

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA - FEE

"ESTRUTURAS ELÉTRICAS PARA
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS
LITOGRÁFICOS EM UM
PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE
CIRCUITOS INTEGRADOS"

ARISTIDES PAVANI FILHO

Orientador: Prof. Dr. Turio Damiani
DEM/C-FEE-UNICAMP

Co-orientador: Prof. Dr. Curt Egon Hennies
DEQ-IFGW-UNICAMP

Este exemplar corresponde à redação final da tese
defendida por Aristides Pavani Filho,
e aprovada pela Comissão
ulgadora em 10.08.90.

Orientador

Dissertação apresentada à
Faculdade de Engenharia Elétrica da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
como parte dos requisitos exigidos
de MESTRE EM ENGENHARIA ELÉTRICA.

CAMPINAS - 1990

Dedico este trabalho aos meus pais "Seo"
Aristides e "Dona" Rosa que trilharam
caminhos mais árduos e longos que o meu
para que eu pudesse chegar até aqui.

À minha esposa Luzia pelo seu amor e
dedicação.

À todos que de alguma maneira
contribuiram para a realização deste
trabalho, e em especial ao professor Curt
pelo acompanhamento e orientação.

RESUMO

Neste trabalho apresentamos um conjunto de estruturas elétricas de teste para avaliação de parâmetros litográficos para serem empregadas na avaliação de um processo industrial de fabricação de circuitos integrados.

Três foram os parâmetros investigados. A largura de linha, o overlay e a densidade de defeitos.

Os circuitos de teste foram produzidos em um fabricante de circuitos integrados no exterior como parte do Projeto Multiusuário PMUCMOS 4, coordenado pelo Centro Tecnológico para a Informática.

Foram fabricados 50 circuitos de teste composto por 9 estruturas de teste, distribuídos em duas colunas de 25 circuitos, dos quais foram avaliados 20 circuitos por coluna.

Os resultados obtidos nos permitiram :

- 1) Avaliar a precisão do método de medidas de parâmetros de litografia através de estruturas elétricas de teste.
- 2) Avaliar a efetividade das estruturas propostas em revelar através dos parâmetros básicos de litografia, as estratégias empregadas pelo fabricante e os parâmetros do processo litográfico.

ESTRUTURAS ELÉTRICAS PARA AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS LITOGRÁFICOS EM UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO 1. ESTRUTURAS DE TESTE ELÉTRICO DE PARÂMETROS LITOGRÁFICOS.

1.1 Introdução.

1.2 As estruturas de teste de parâmetros litográficos propostas e a descrição da metodologia de obtenção.

1.3 O processo de litografia por feixe eletrônico.

1.4 A largura de linha.

1.4.1 O efeito de proximidade.

1.4.2 Estruturas de teste para avaliação da correção do efeito de proximidade.

1.4.3 Estruturas de teste para medida da largura de linha.

1.4.4 Método de Van Der Pauw para determinação da resistência de folha.

1.5 Overlay e o Registro.

1.5.1 O erro de Overlay e o erro de Registro.

1.5.2 A avaliação do erro de overlay.

1.5.3 Estruturas de teste para a avaliação do erro de overlay.

1.6 A densidade de defeitos.

CAPÍTULO 2. A LARGURA DE LINHA E O DESEMPENHO DO PROCESSO DE LITOGRAFIA.

2.1 Estruturas de resistência tipo ponte.

2.2 Estrutura de teste proposta.

2.3 O erro do método de medida da largura de linha nas estruturas de testes elétricos.

2.4 Os procedimentos das medidas de resistência de folha e análise dos resultados obtidos.

2.5 Os procedimentos das medidas de largura de linha e a análise dos resultados obtidos.

2.5.1 Efeito de proximidade.

2.5.2 Aberrações do sistema eletroóptico.

2.5.3 Desvios da largura de linha induzidos pelo processo.

CAPÍTULO 3. O ERRO DE OVERLAY

3.1 Estrutura de teste proposta.

3.2 O erro do método de avaliação do erro de overlay.

3.3 Os procedimentos das medidas e a análise dos resultados obtidos.

CAPÍTULO 4. A DENSIDADE DE DEFEITOS.

4.1 Estrutura de teste proposta.

4.2 Os procedimentos das medidas e análise dos resultados obtidos.

CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES.

CAPÍTULO 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- APÊNDICE I - Tabela das medidas de resistência de folha através de estruturas Van der Pauw.
- APÊNDICE II - Tabela das medidas de largura de linha em estruturas de polissilício.
- APÊNDICE III - Tabela das medidas de largura de linha em estruturas de metal.
- APÊNDICE IV - Tabela das medidas de overlay.
- APÊNDICE V - Programa para automatização da medida de largura de linha.

CAPÍTULO 1

ESTRUTURAS DE TESTE ELÉTRICO DE PARÂMETROS LITOGRAFICOS

1.1 INTRODUÇÃO:

O processo de fabricação de circuitos integrados envolve um número muito grande de etapas de processamento, que são em princípio uma sucessão de quatro etapas básicas sequenciadas de acordo com a tecnologia empregada. As etapas básicas de processamento são :

- a) Deposição de camadas condutoras ou isolantes
- b) Remoção de camadas
- c) Litografia
- d) Limpeza

Dentre estas etapas, a de litografia contribue com mais de 50% do número total de etapas empregadas no processo de fabricação e é responsável pela grande maioria dos problemas de contaminação e de controle de processo. Os avanços da litografia continuam sendo o fator de motivação para o aumento no nível de integração de microcircuitos. Por exemplo, memórias RAM dinâmicas têm quadruplicado o nível de integração a cada três anos [1]. Um dos grandes desafios impostos a litografia é o de se manter à frente da demanda de integração. Os parâmetros que usualmente caracterizam o grau de evolução da tecnologia litográfica são: dimensão crítica, overlay* e densidade de defeitos. Apresentamos nas figuras 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 representações aproximadas das reduções na dimensão crítica, overlay e densidade de defeitos em função da densidade de integração para memórias RAM dinâmicas. O marco em 16 megabits representa o estágio atual de desenvolvimento da indústria e está limitado basicamente pelo estágio de desenvolvimento das técnicas litográficas .

* O erro de overlay é o erro de alinhamento entre dois níveis de máscaras, e expressa a precisão da superposição destes níveis.

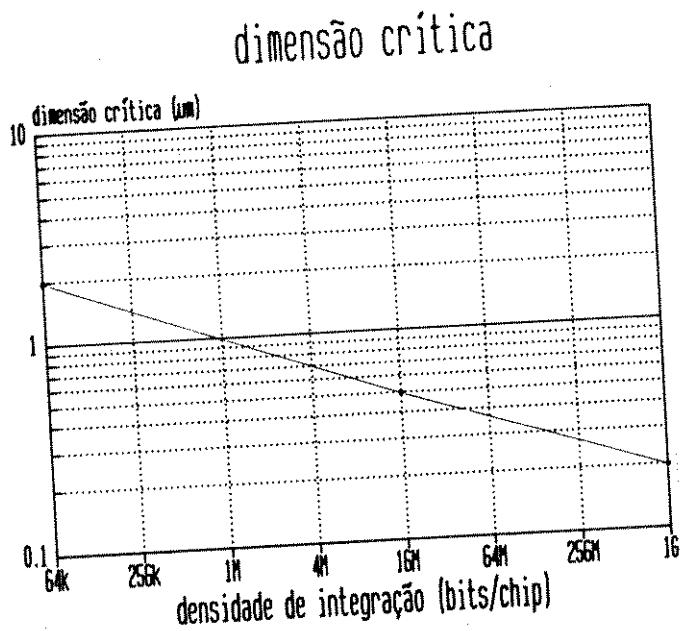


fig 1.1.1

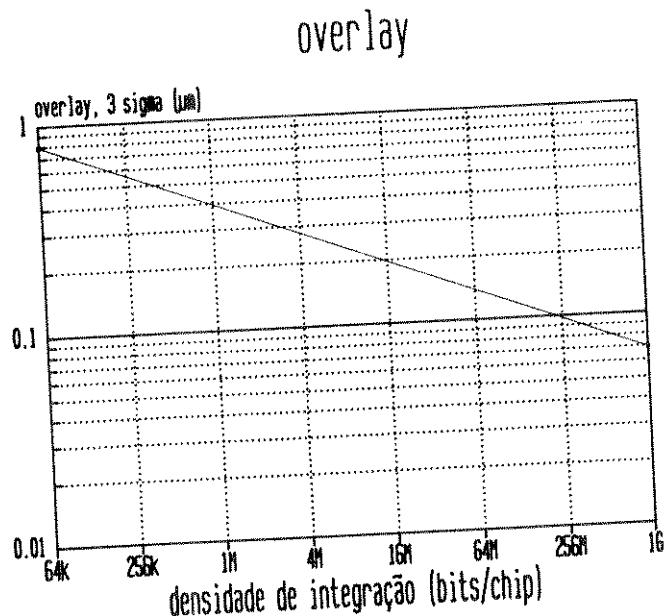


fig 1.1.2

densidade de defeitos

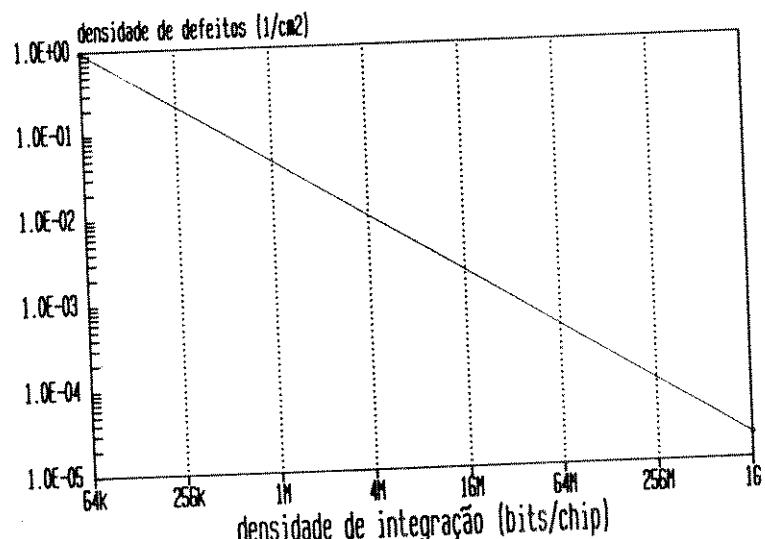


fig 1.1.3

Figuras 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 - Representação da redução dos parâmetros litográficos em função do aumento da densidade de integração para memórias RAM dinâmicas (DRAMs).

A figura 1.1.4 mostra os limites atuais e as tendências de evolução das ferramentas litográficas atualmente disponíveis. Existe portanto a necessidade de se desenvolver novas ferramentas litográficas de geração de configurações, replicação e metrologia que possibilitem atingir o limite de 1 gigabit.

A metrologia associada ao processo litográfico tem sido, e continuará sendo, pressionada aos limites das técnicas empregadas, devido à necessidade da sua utilização nos diversos estágios de processamento tais como: caracterização do processo, medidas in situ para controle de processo e equipamento e medidas no produto. Enquanto que para o estágio de caracterização existe uma demanda maior na exatidão do método de medida, o controle e medidas no produto demandam por rapidez e repetibilidade. A figura 1.1.5 mostra as tendências de evolução da metrologia em função do aumento da integração.

Dependendo do produto os requisitos para o erro de overlay geralmente se encontram entre 30% e 40% da precisão da dimensão crítica. A capacidade de detecção de defeitos e partículas requeridas são da ordem de um décimo da dimensão crítica.

Alternativas Litográficas

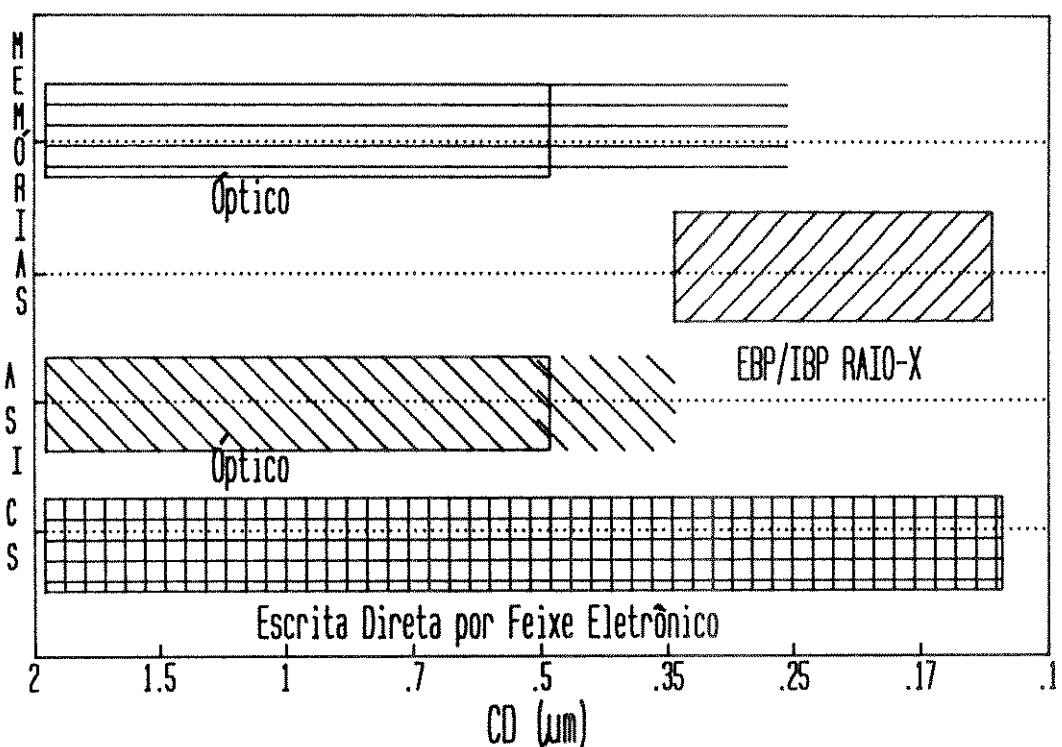


fig 1.1.4

Figura 1.1.4 - Limites atuais e tendências futuras de evolução das principais ferramentas litográficas.

Metrologia

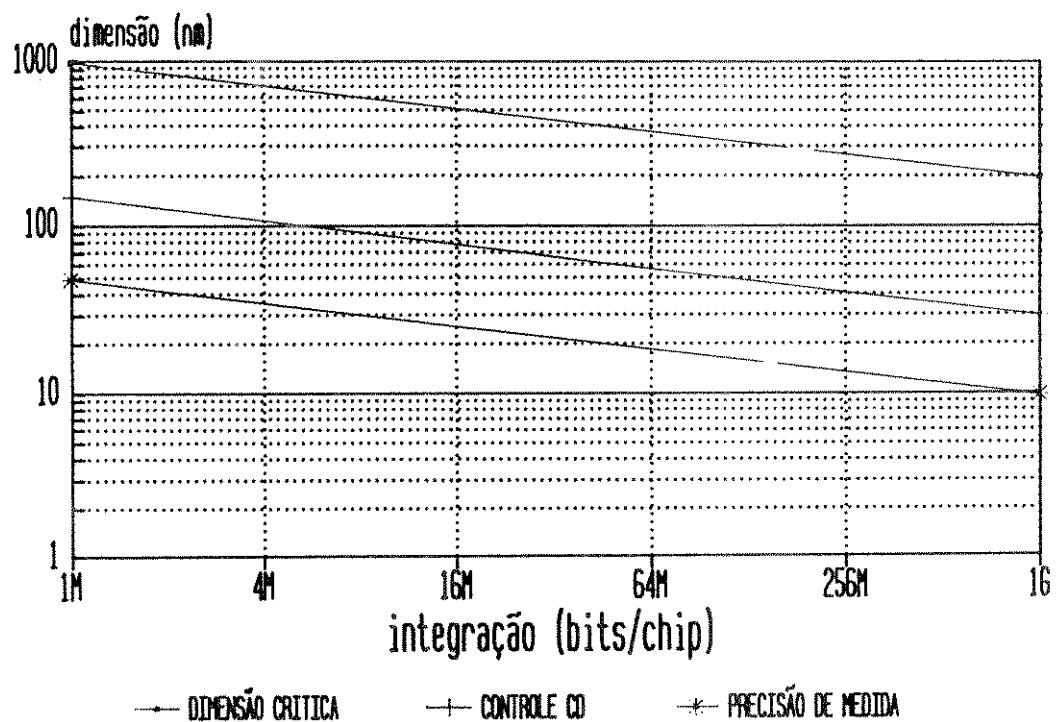


fig 1.1.5

Figura 1.1.5 - Tendência da metrologia litográfica.

O conhecimento das limitações tecnológicas do processo de fabricação impostas pelo conjunto de processo e equipamento litográfico é de vital importância no controle e no desenvolvimento do processo. Para isto é fundamental o emprego de técnicas de metrologia que possibilitem a avaliação dos parâmetros litográficos diretamente no produto final, que dependendo do processo empregado, pode se constituir em máscaras, dispositivos de estado sólido ou circuitos integrados (CIs). As técnicas normalmente empregadas incluem a utilização de equipamentos específicos para cada parâmetro investigado, como microscópios ópticos para inspeção visual de defeitos, microscópios eletrônicos e sistemas de tratamento digital de imagem para medida de dimensões críticas e overlay. Cada uma destas técnicas apresentam deficiências quando aplicadas na avaliação do processo através da medida do produto pronto. A microscopia óptica como técnica de inspeção é altamente dependente do operador, e é limitada quanto a dimensão dos defeitos detectados. A utilização de equipamentos automáticos de deteção de defeitos através de tratamento digital de imagem, tem sua aplicação limitada devido a incapacidade de deteção de defeitos localizados nos níveis mais internos do circuito integrado. A microscopia eletrônica, apesar da alta resolução, apresenta como deficiência básica a necessidade do preparo da amostra a ser analisada e o tempo necessário para se obter um grande número de medidas para avaliação estatística.

Um método que seja ao mesmo tempo simples, preciso, rápido, que possa avaliar os parâmetros litográficos nos vários níveis do processo, e que seja único para todos os parâmetros apresenta-se como ideal para a avaliação do processo através do produto.

A avaliação de parâmetros litográficos através de estruturas elétricas especiais definidas nas diversas camadas condutoras de um circuito integrado, por apresentarem todas as vantagens acima citadas, é uma alternativa a ser utilizada pela indústria no controle e desenvolvimento de processos.

O presente trabalho apresenta um conjunto de estruturas elétricas de teste para avaliação de parâmetros de litografia de um processo industrial de fabricação de circuitos integrados. Um circuito de teste contendo um conjunto de estruturas de teste foi fabricado utilizando escrita direta por feixe de elétrons como etapa litográfica, estas estruturas foram projetadas de maneira a explorar as características deste equipamento e do processo litográfico a ele associado. Os resultados obtidos e as análises destes resultados deverão mostrar a viabilidade da utilização deste método.

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um conjunto de estruturas de teste, para serem fabricadas em silício concomitantemente com o processo industrial de fabricação de CI's que se deseja caracterizar.

1.2 As estruturas de teste de parâmetros litográficos propostas e a descrição da metodologia de obtenção.

As estruturas de teste para avaliação de parâmetros litográficos foram projetadas para serem empregadas na avaliação de parâmetros de litografia, na etapa de definição dessas estruturas em uma camada de material condutor, em um processo de fabricação de circuitos integrados com tecnologia CMOS. A fabricação destas estruturas não deve impor nenhuma alteração na sequência de processo normalmente utilizada para a fabricação de um circuito integrado. Estas estruturas podem portanto serem empregadas na avaliação dos equipamentos e dos processos envolvidos nas etapas de definição litográfica de camadas condutoras como silício dopado, polissilício e metal. Em particular, a estrutura para a avaliação do erro de overlay utiliza a característica de auto alinhamento da etapa de definição das regiões ativas de dreno e fonte dos transistores CMOS, que são produzidos através da implantação iônica após a etapa de definição das portas em polissilício. Esta estrutura mede portanto o desalinhamento entre os níveis de definição das regiões ativas dos transistores e os do polissilício. É necessário que o processo CMOS possua esta sequência de etapas para que a estrutura funcione. O auto alinhamento das regiões ativas dos transistores através da implantação de ions utilizando a porta de polissilício como máscara, é um procedimento padrão nos processos de fabricação de circuitos integrados com tecnologia CMOS.

Para testar a validade da utilização de estruturas de teste elétrico para a avaliação de parâmetros litográficos em um processo de fabricação de circuitos integrados convencional, foram projetadas estruturas de teste como parte do Projeto Multiusuário PMUCMOS 4, coordenado pelo Centro Tecnológico para Informática, junto com projetos de outros centros de pesquisa, universidades e empresas. Estas estruturas foram processadas em uma empresa no exterior, resultando um lote de três lâminas das quais uma foi reservada para ser medida, outra foi dividida e os seus circuitos foram encapsulados e a última foi mantida como reserva.

A fundição de silício utilizada para a fabricação das estruturas de teste, correntemente utiliza um processo CMOS 2 μ m com porta de silício pôco N com dois níveis de metal. O material básico para este processo é uma lâmina de silício tipo P de 125 mm de diâmetro na qual um substrato epitaxial é depositado. As portas dos transistores são de polissilício, com interconexões sendo feitas nos dois níveis de metal. O processo emprega escrita direta por feixe eletrônico como etapa de definição litográfica de todos os níveis do circuito. A figura 1.2.1 mostra um corte de uma célula CMOS do processo acima descrito.

Para cada projeto colocado no PMUCMOS 4 resultaram 50 circuitos. A figura 1.2.2 mostra a distribuição dos circuitos de teste de parâmetros litográficos dentro da lâmina processada.

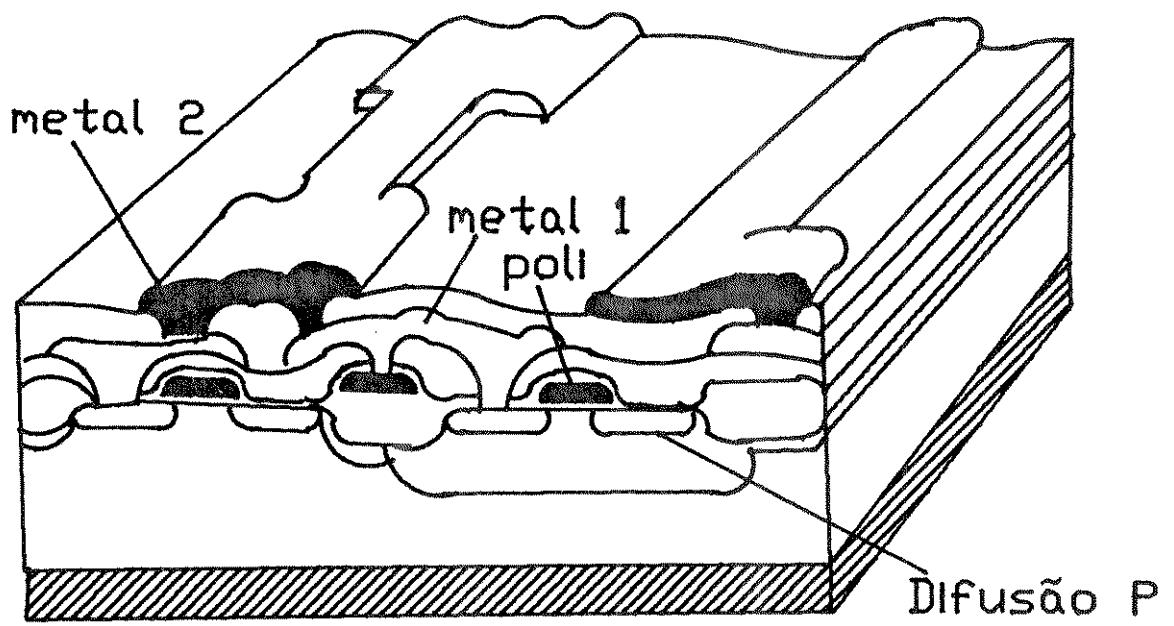


Figura 1.2.1. Corte de uma célula CMOS característica do processo utilizado para fabricação das estruturas de teste.

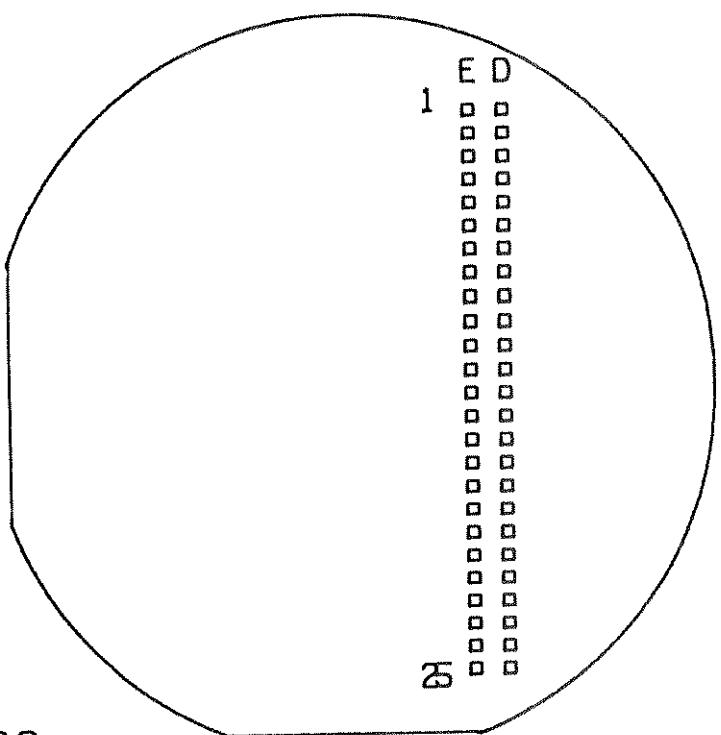


fig 1.2.2

Figura 1.2.2. Distribuição dos circuitos de teste de parâmetros litográficos dentro da lâmina processada.

As estruturas de teste foram distribuídas em duas colunas de 25 circuitos cada, situadas na extremidade direita da lâmina. Esta distribuição apresenta o inconveniente de apenas caracterizar uma pequena porção da lâmina, não fornecendo resultados que nos permitam avaliar o comportamento do processo e dos equipamentos litográficos por toda a área da lâmina. Outro inconveniente apresentado por esta distribuição, é o de ter uma maior probabilidade de ocorrência de circuitos defeituosos devido a não uniformidades do processo na periferia da lâmina. Por outro lado, a avaliação dos parâmetros de litografia nestas condições pode nos trazer informações importantes sobre o controle do processo litográfico e sua sensibilidade às não uniformidades nos processos de deposição de camadas e de resistes, bem como sobre o desempenho dos equipamentos litográficos utilizados em condições não ideais.

Dos 25 circuitos de teste fabricados foram medidos os primeiros 20 de cada coluna, tendo sido reservado os últimos cinco para comparação posterior e para testes dos procedimentos de medida. Os circuitos foram codificados quanto a sua posição sendo numerados de 1 à 20 de cima para baixo, para a coluna da direita e esquerda. Portanto um circuito identificado como E15 corresponde ao décimo quinto circuito a contar de cima, pertencente a coluna da esquerda.

Cada circuito de teste está dividido em quatro quadrantes, cada um contendo um mesmo conjunto de estruturas. Estes quadrantes foram codificados em: Superior Esquerdo (SE), Superior Direito (SD), Inferior Esquerdo (IE) e Inferior Direito (ID).

Cada quadrante é composto de um conjunto de nove estruturas de teste para avaliação de parâmetros litográficos e três estruturas de Van Der Pauw.

As estruturas de avaliação de parâmetros foram codificadas de acordo com suas configurações internas, e também de acordo com as camadas condutoras objeto de pesquisa. Desta maneira a cada tipo de estrutura corresponde um código, a saber:

1A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de intraproximidade em polissilício com linhas de 1 um e 2 um. Figura 1.2.3.

2A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de intraproximidade em polissilício com linhas de 2 um e 4um. Figura 1.2.4.

3A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade em polissilício com linhas de 1 um e 2 um com separação de 1 um. Figura 1.2.5.

4A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade em polissilício com linhas de 1 um e 2 um com separação de 2 um. Figura 1.2.6.

5A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em polissilício com linhas de 1 um e 2 um. Figura 1.2.7.

6A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em polissilício com linhas de 2 um e 4 um. Figura 1.2.8.

1B- Estrutura para avaliação do erro de overlay . Figura 1.2.9.

6C- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em metal 1 com linhas de 2 um e 4 um definidas sobre estrutura periódica em polissilício. Figura 1.2.10.

7C- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em metal 1 com linhas de 2 um e 4 um. Figura 1.2.11.

POLI- Estrutura Van der Pauw para avaliação da resistência de folha da camada de polissilício. Figura 1.2.12.

DIF - Estrutura Van der Pauw para avaliação da resistência de folha da camada de silício dopado. Figura 1.2.13.

META- Estrutura Van der Pauw para avaliação da resistência de folha da camada de metal 1. Figura 1.2.14.

A figura 1.2.15. mostra a subdivisão da área do circuito de teste em quadrantes e distribuição das estruturas de teste no interior do quadrante.

Esta codificação foi utilizada durante as etapas de medida e avaliação dos resultados servindo como referência na correlação dos parâmetros avaliados com a posição relativa na lâmina processada.

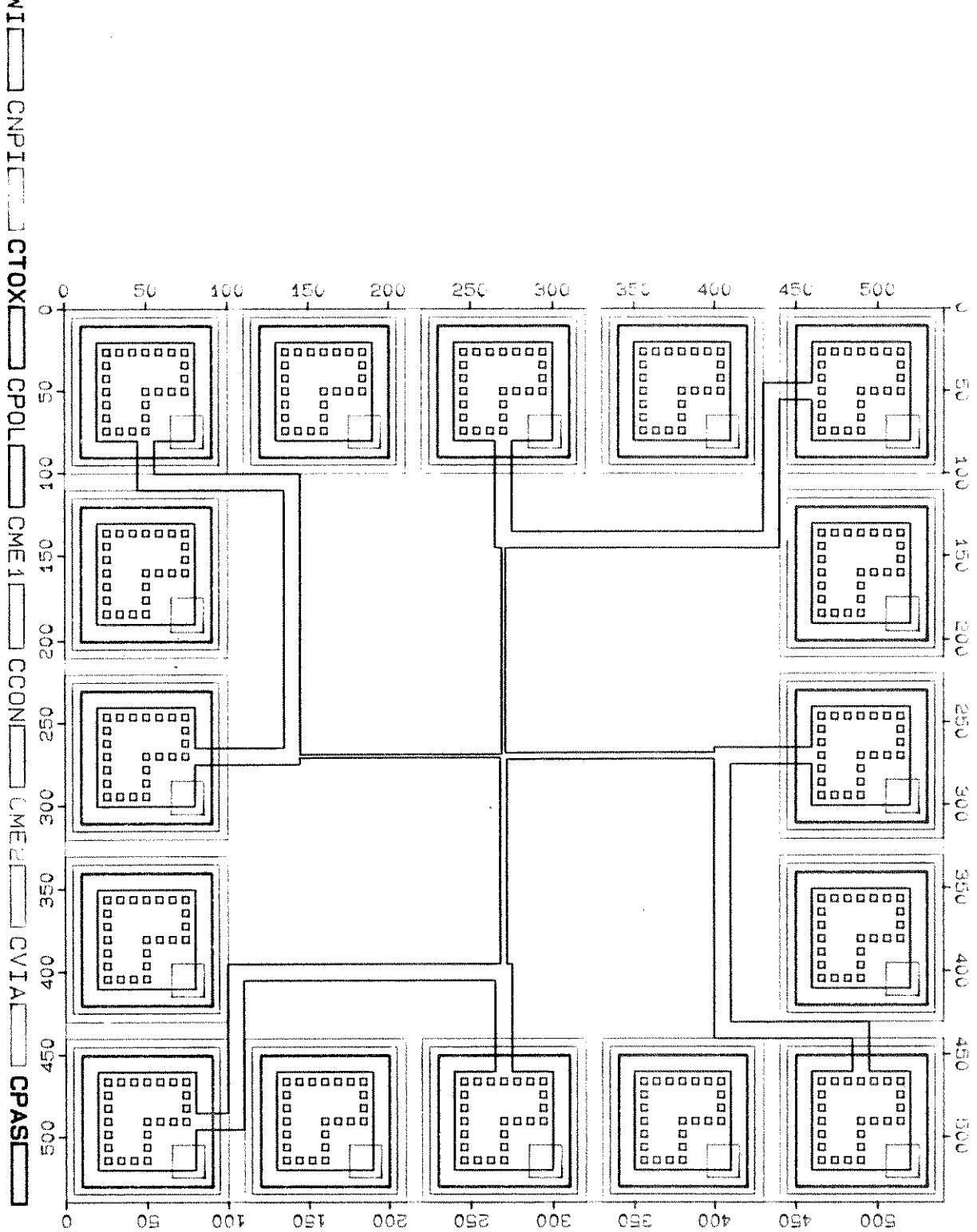


Figura 1.2.3. 1A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de intraproximidade em polissilício com linhas de 1 um e 2 um.

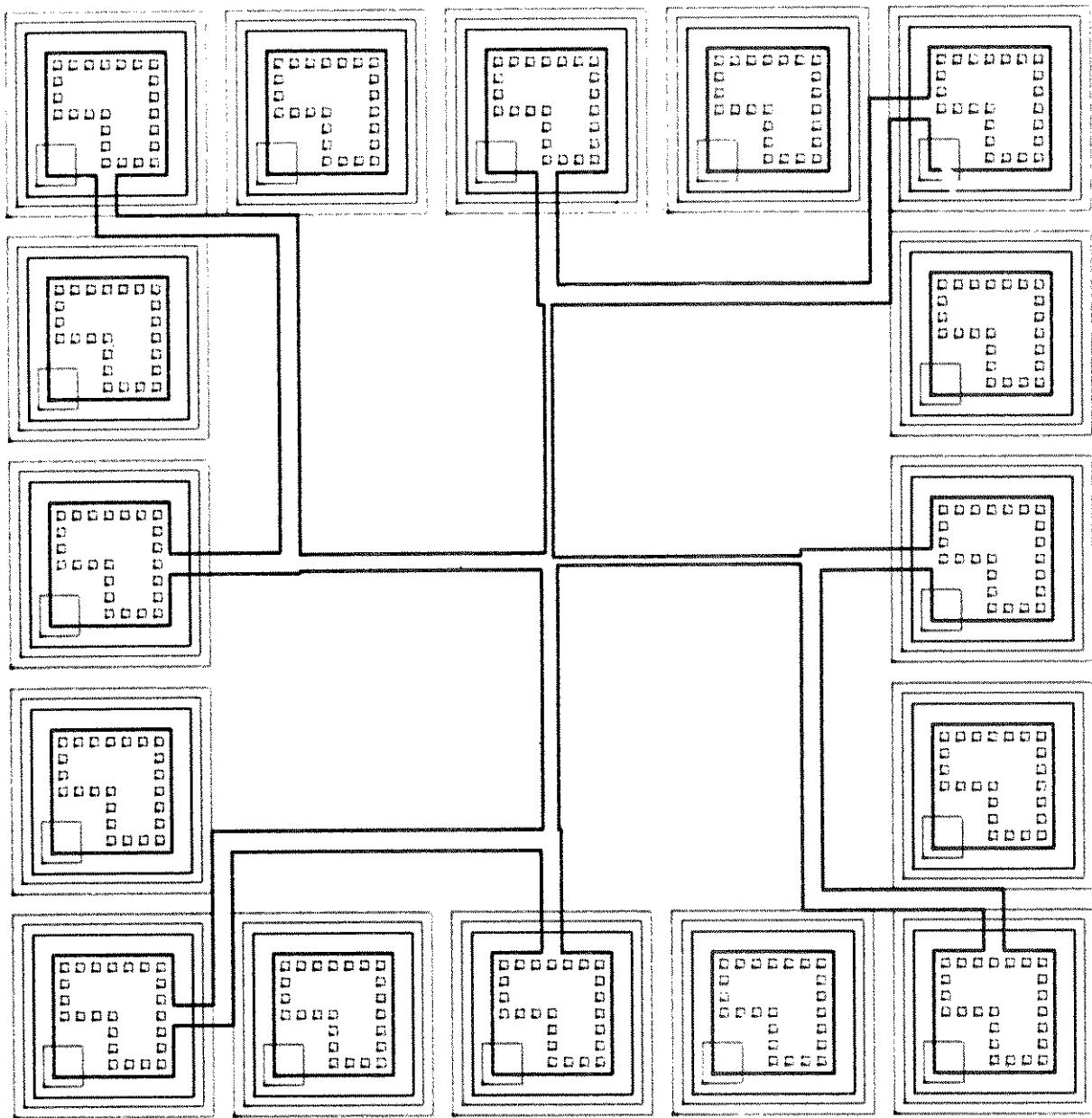


Figura 1.2.4. 2A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de intraproximidade em polissilício com linhas de 2 um e 4um.

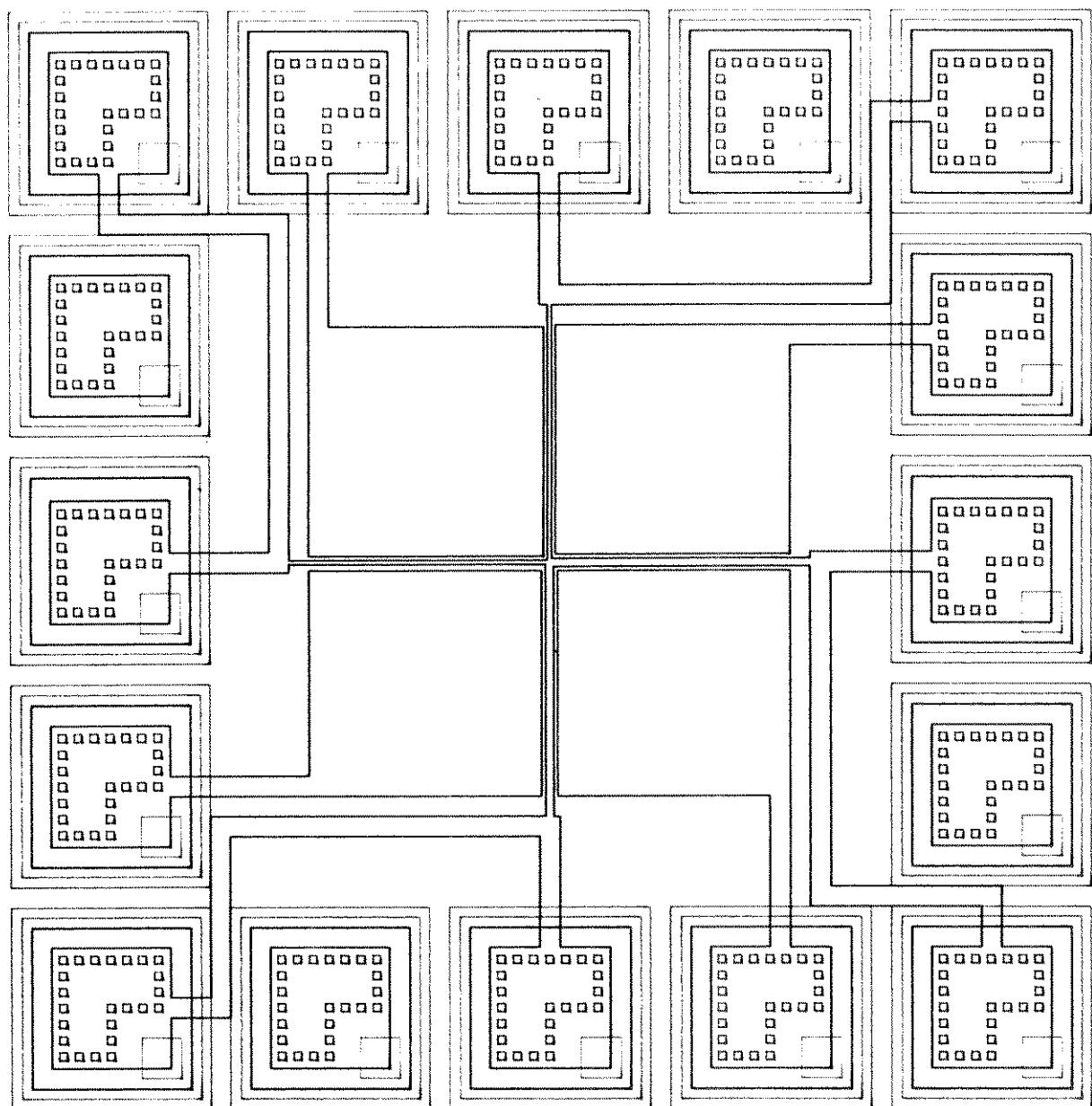


Figura 1.2.5. 3A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade em polissilício com linhas de 1 um e 2 um com separação de 1 um.

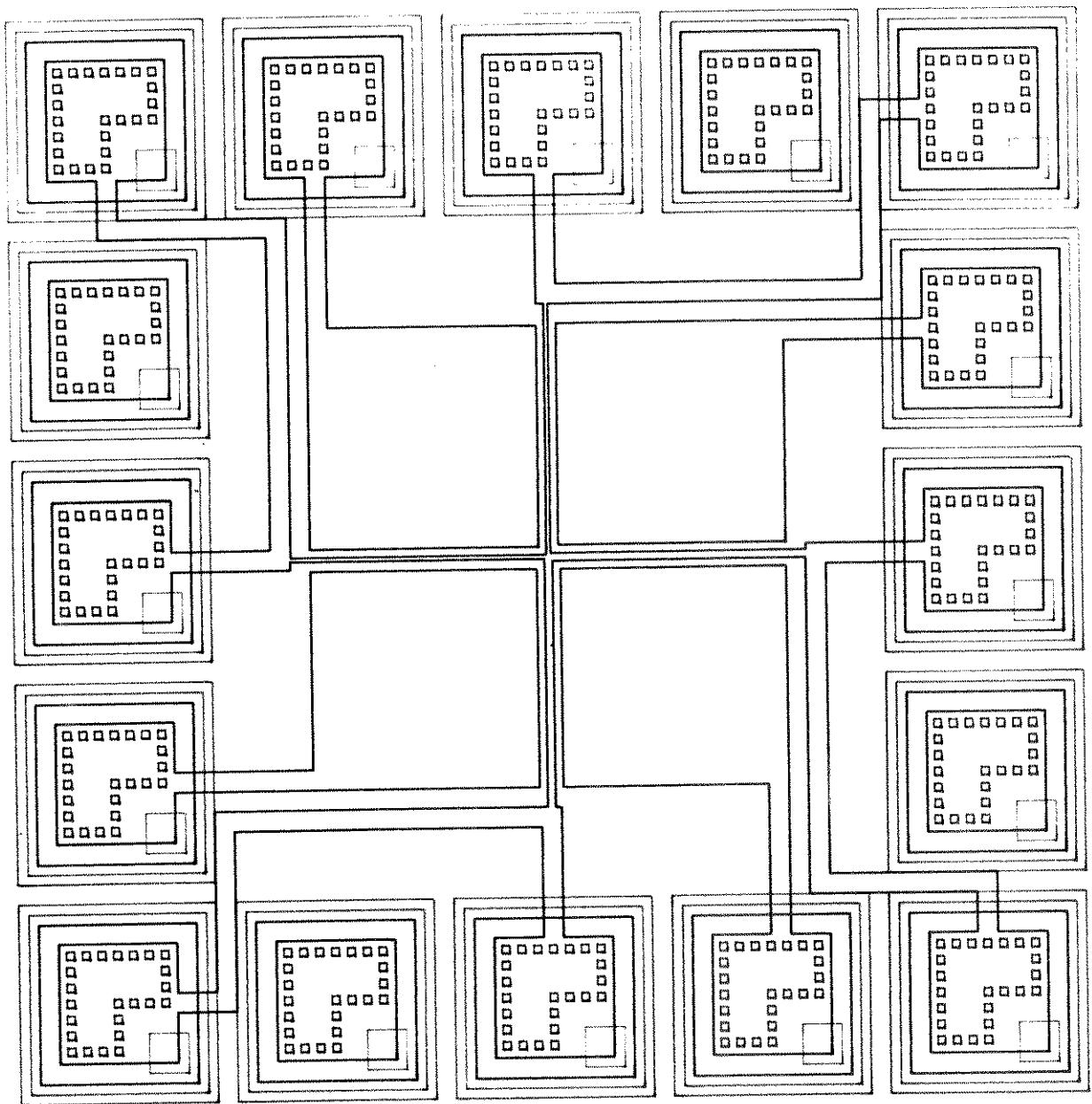


Figura 1.2.6. 4A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade em polissilício com linhas de 1 um e 2 um com separação de 2 um.

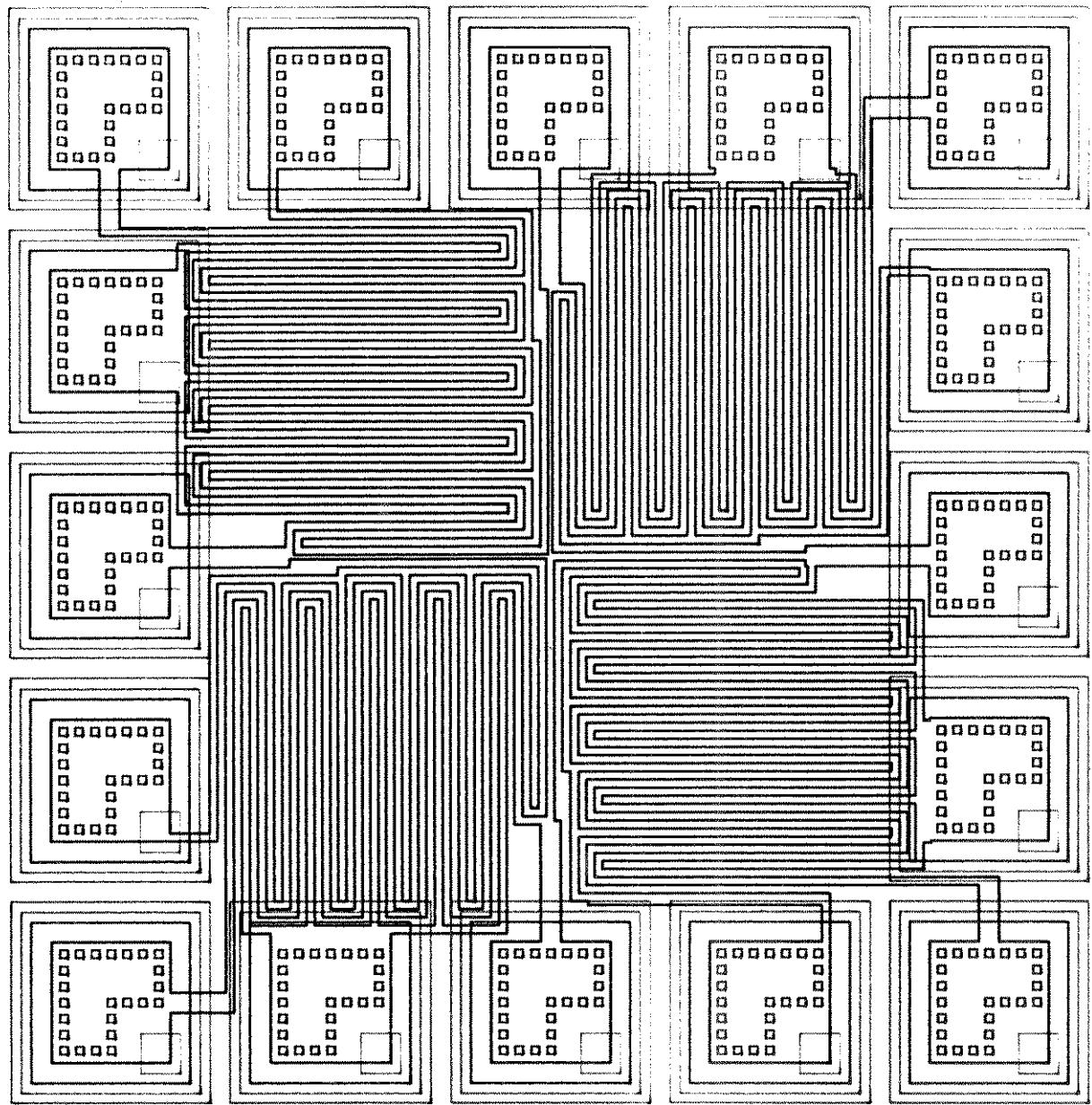


Figura 1.2.7. 5A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em polissilício com linhas de 1 um e 2 um.

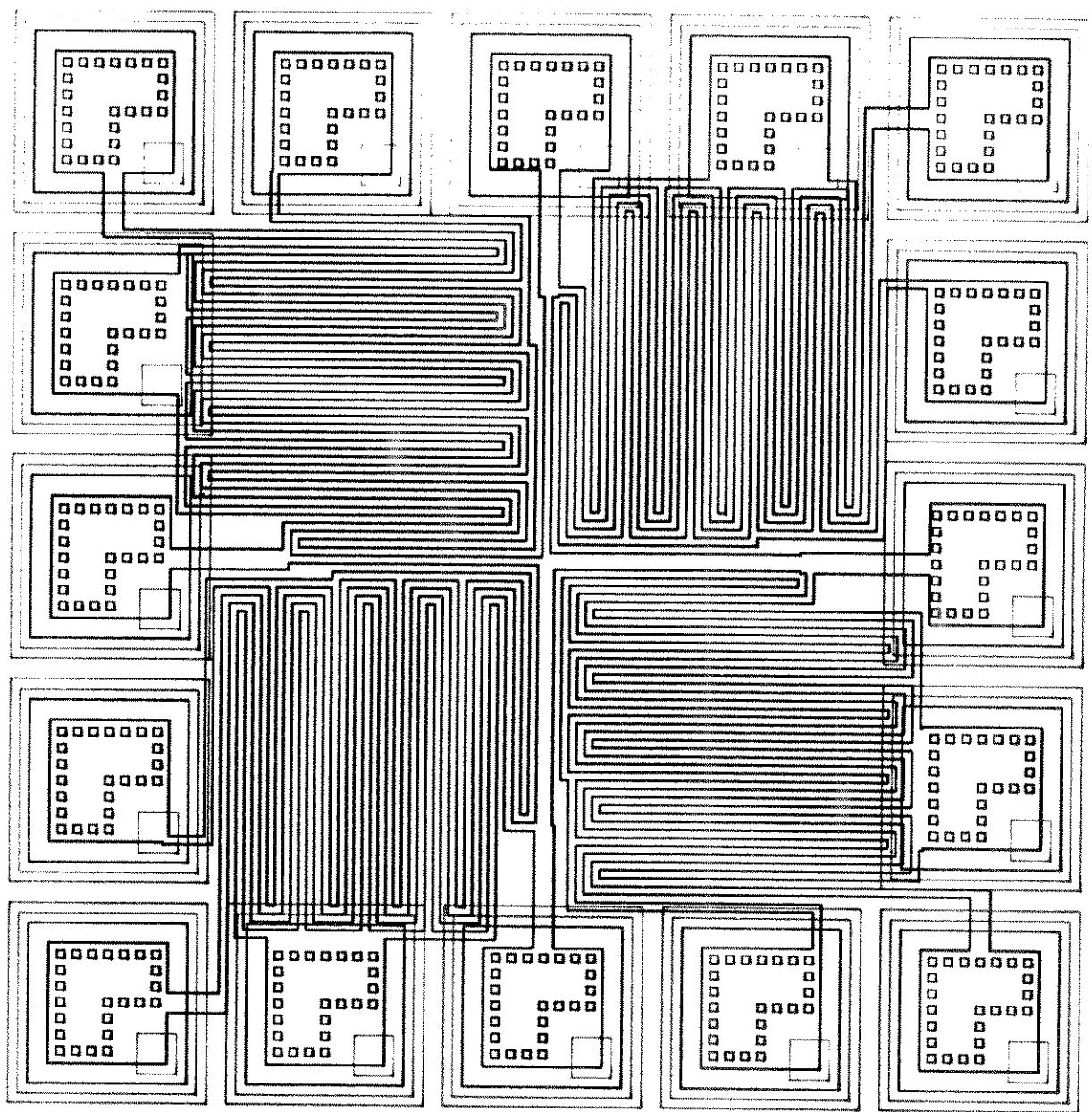


Figura 1.2.8. 6A- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em polissilício com linhas de 2 um e 4 um.

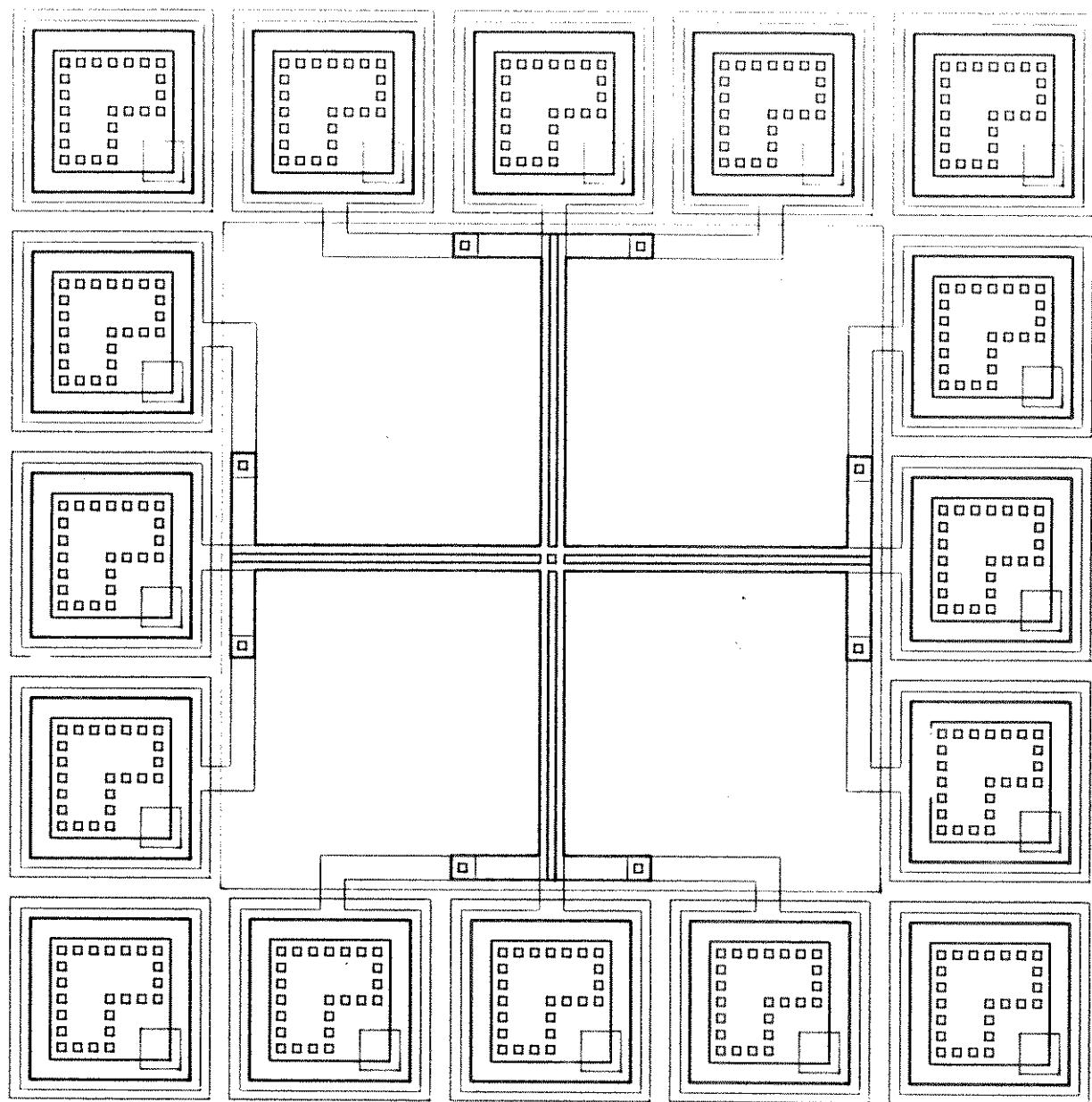


Figura 1.2.9. 1B- Estrutura para avaliação do erro de overlay

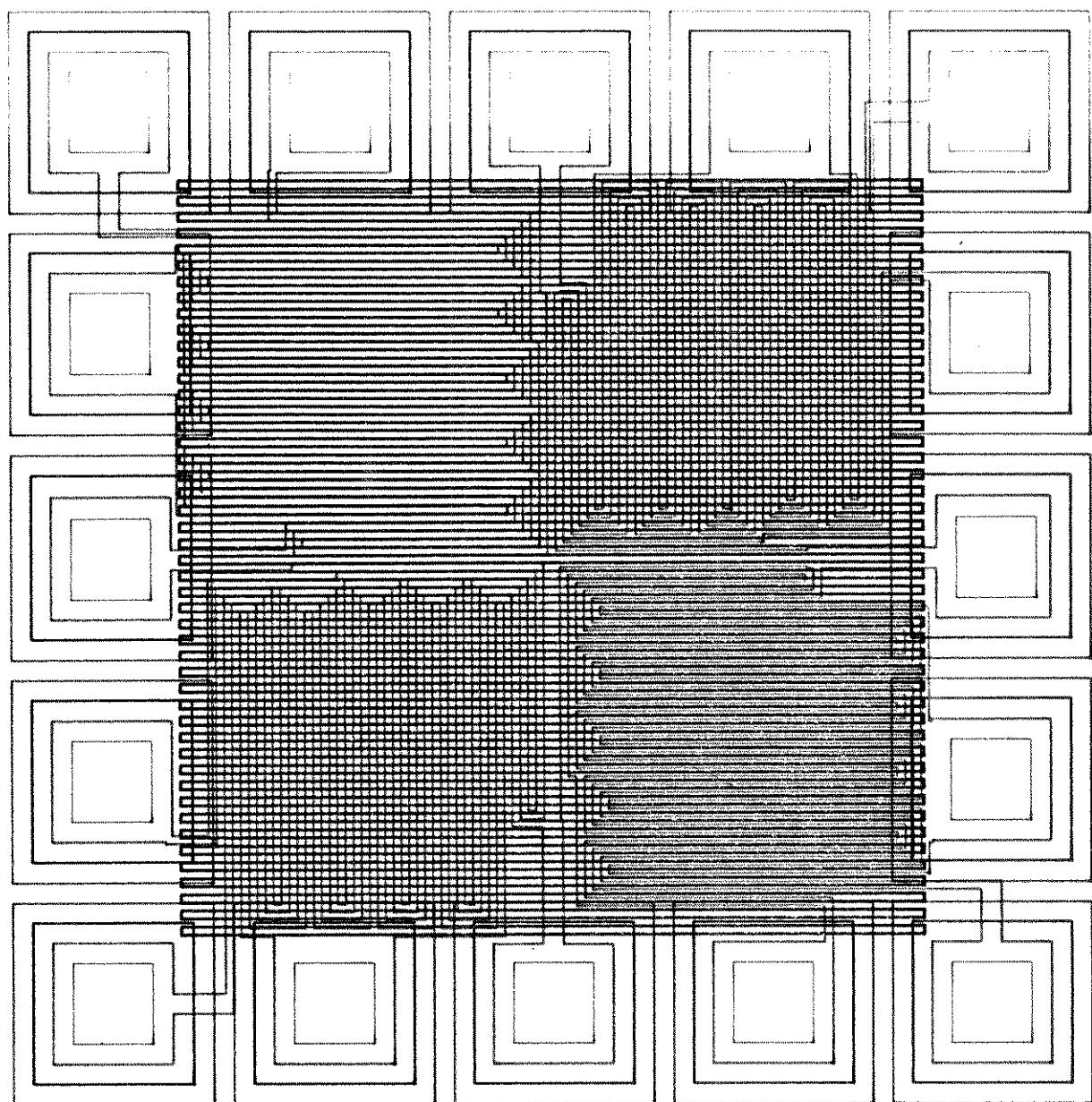


Figura 1.2.10. 6C- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em metal 1 com linhas de 2 um e 4 um definidas sobre estrutura periódica em polissilício.

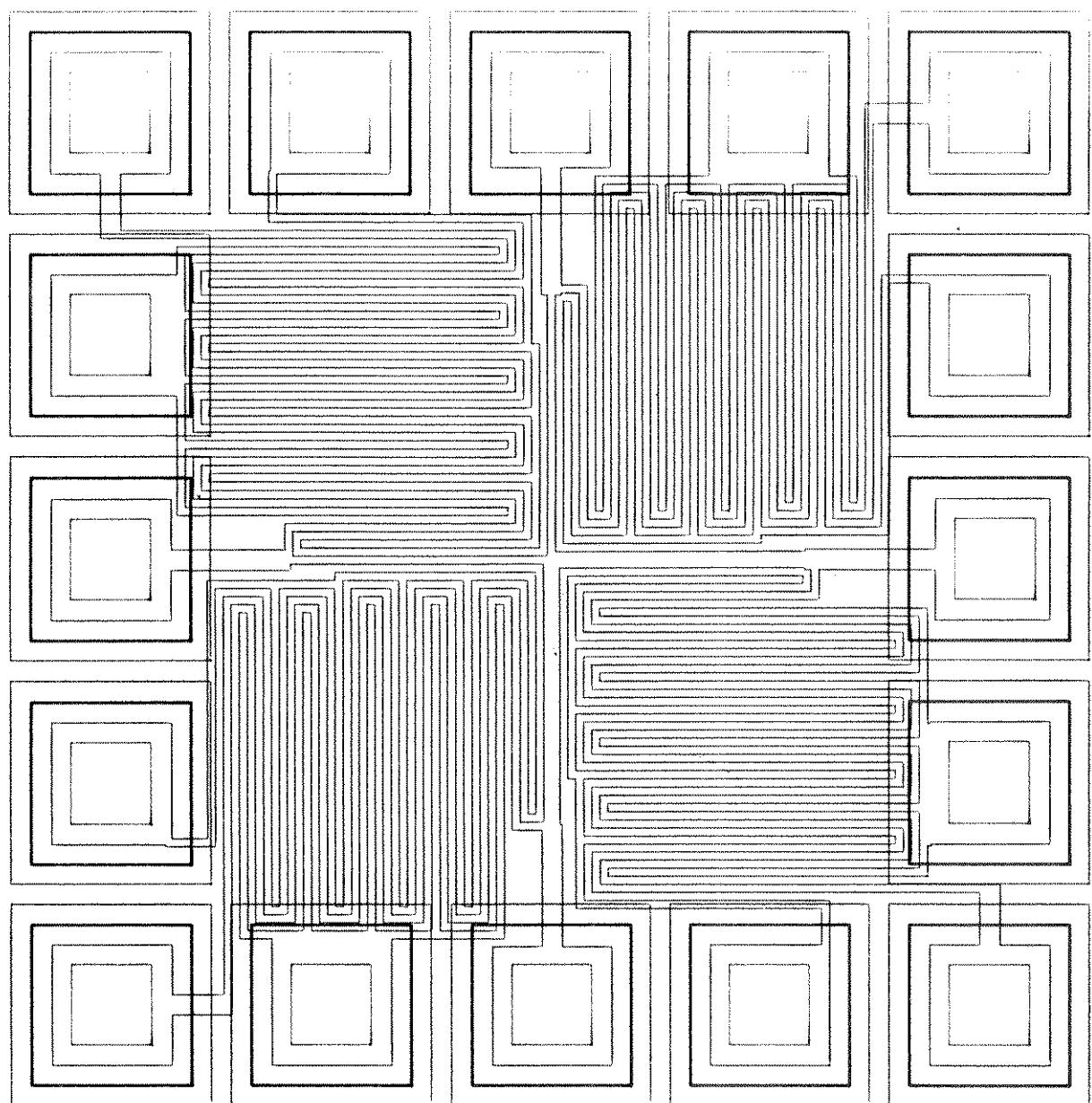


Figura 1.2.11. 7C- Estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade e densidade de defeitos em metal 1 com linhas de 2 um e 4 um.

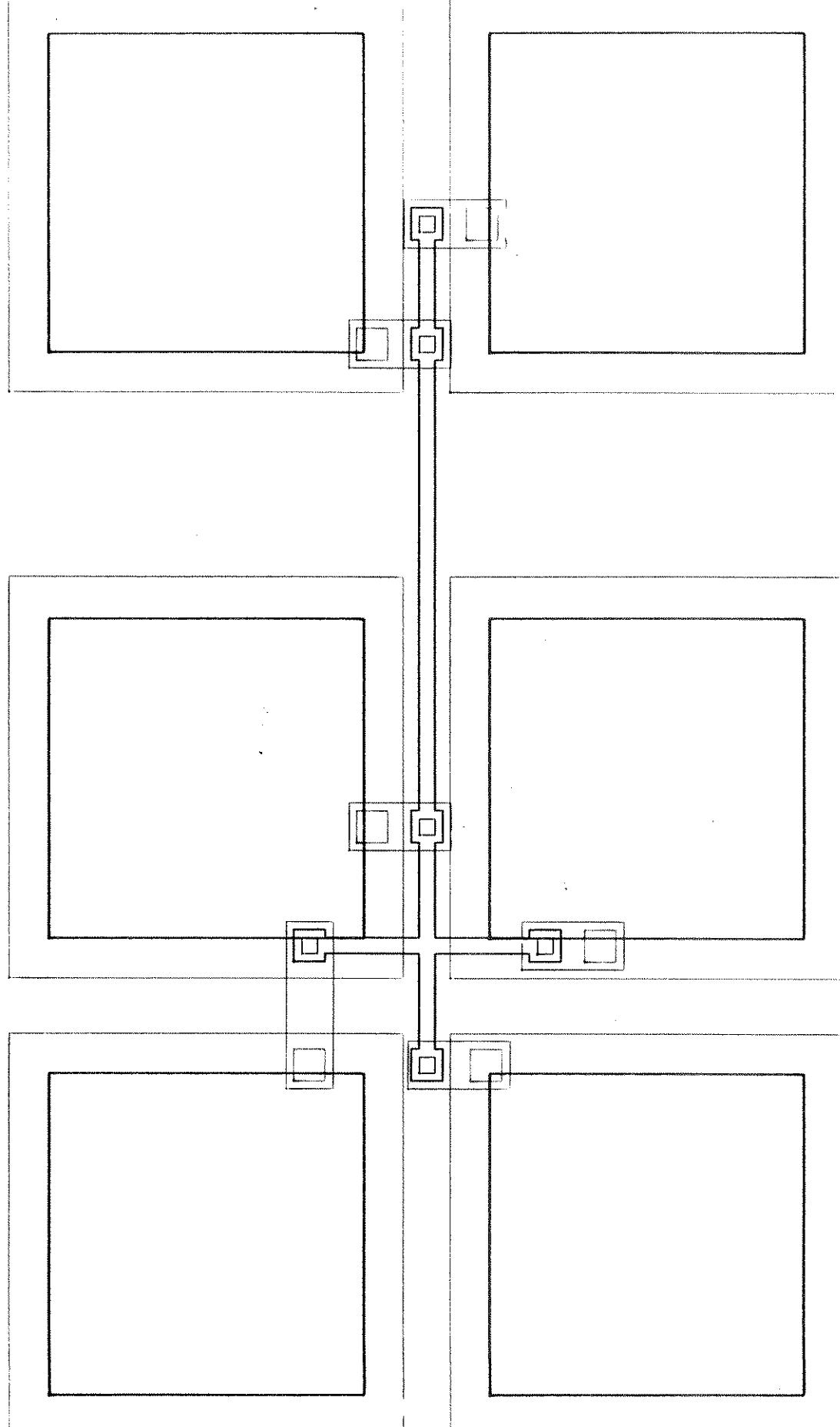


Figura 1.2.12. POLI- Estrutura Van der Pauw para avaliação da resistência de folha da camada de polissilício.

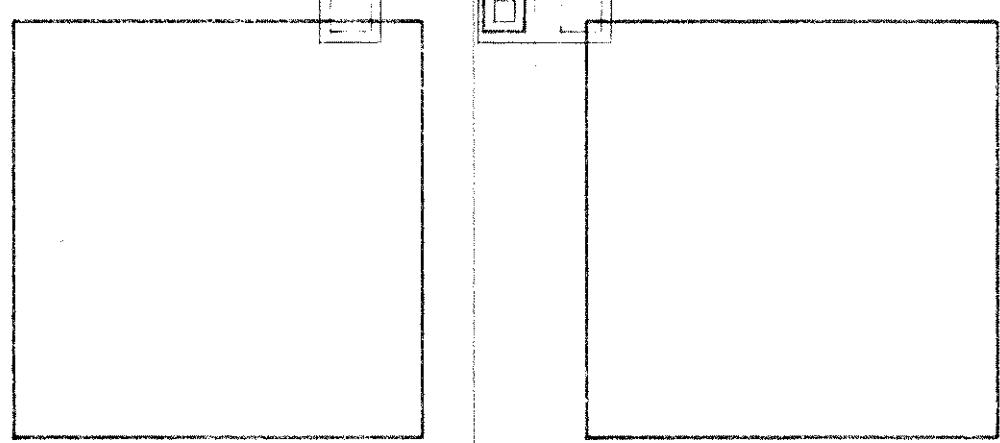
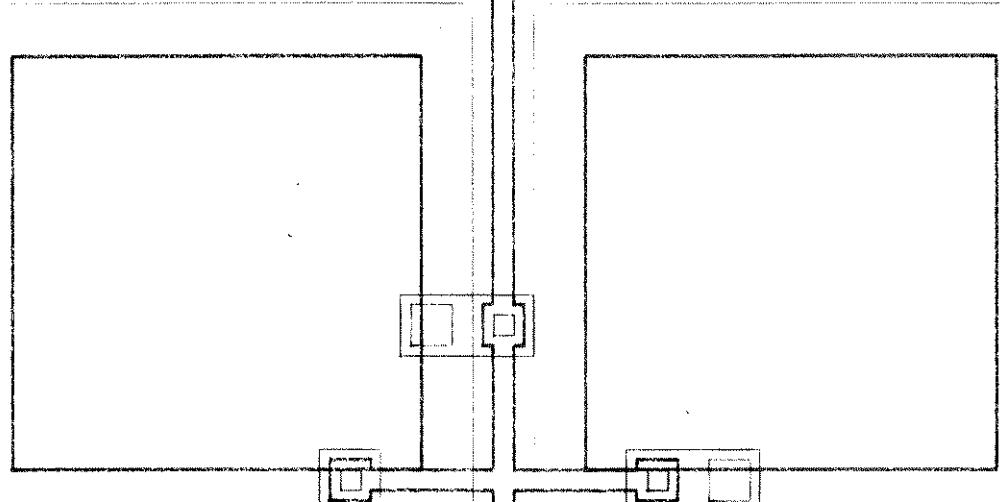
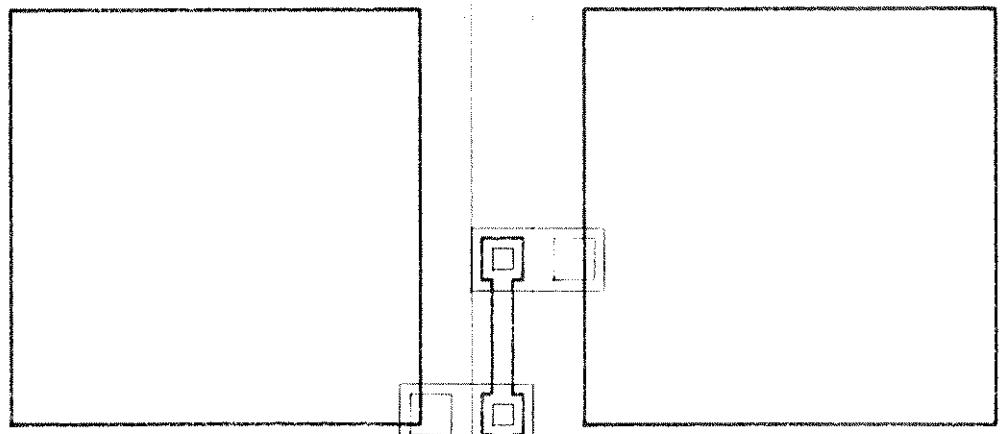


Figura 1.2.13. DIF - Estrutura Van der Pauw para avaliação da resistência de folha da camada de silício dopado.

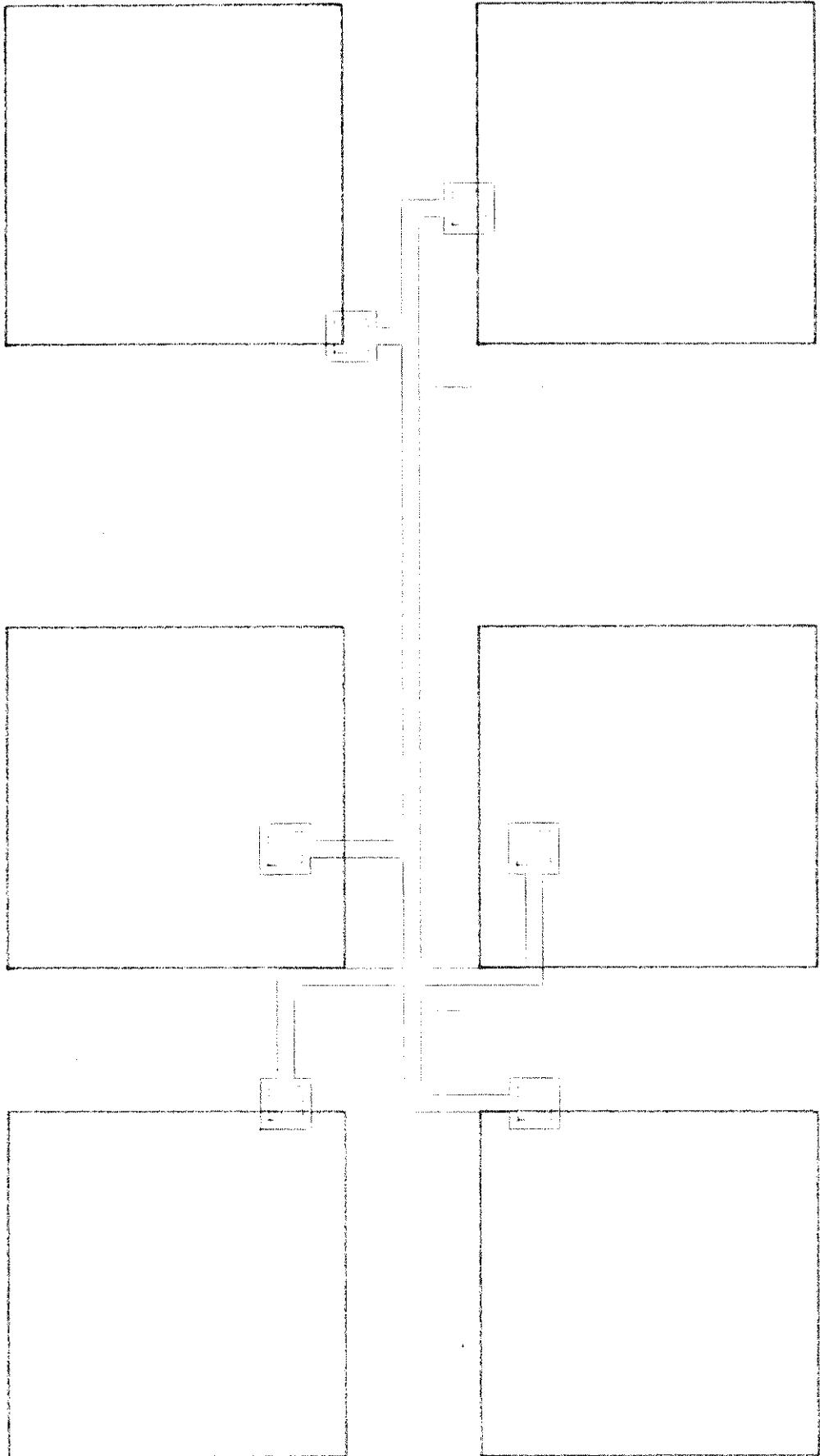
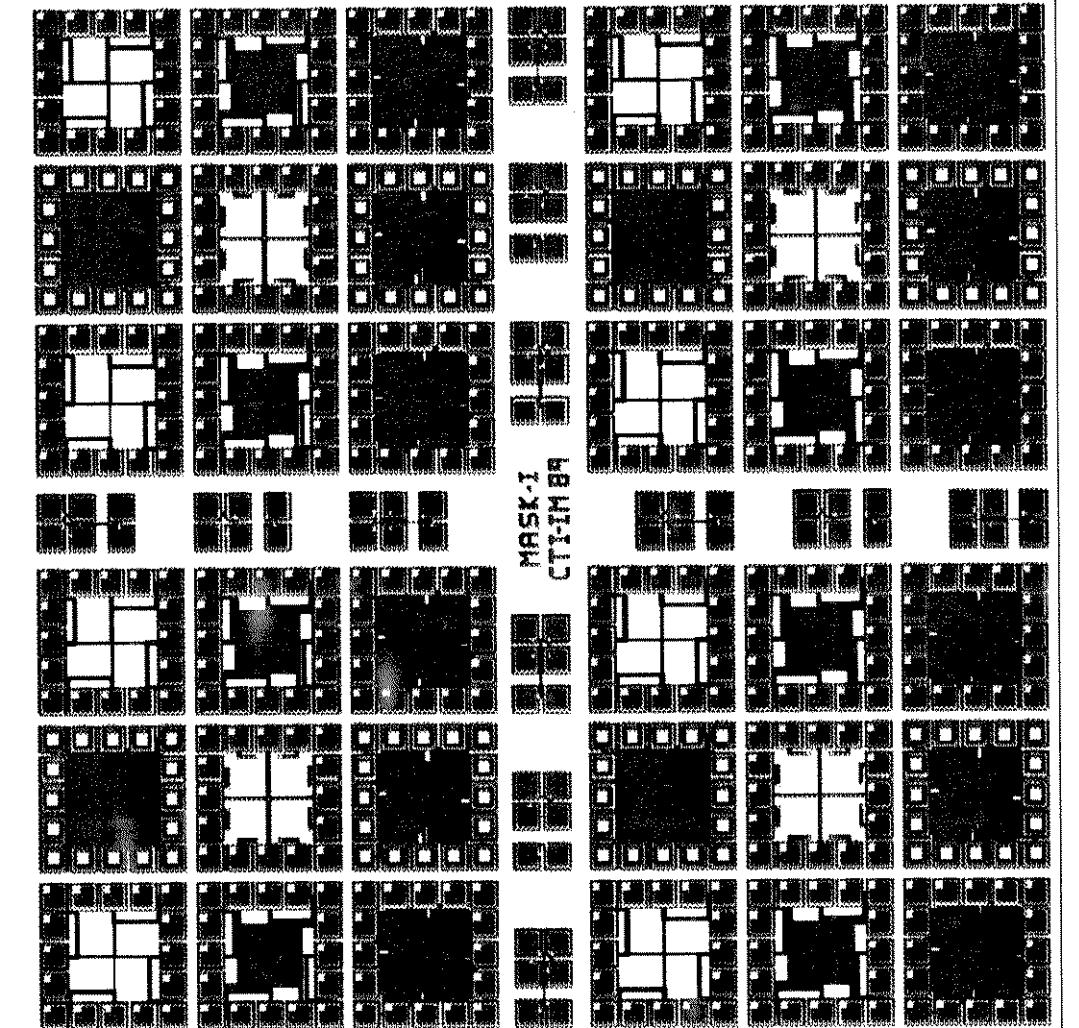


Figura 1.2.14. META- Estrutura Van der Pauw para avaliação da resistência de folha da camada de metal 1.



EDIT DIR Save Write ATTR Insta SELec PRpty RDraw Expnd PEEK Pan Zoom VIEW LAST 45s Grid Snap BOXes WIRes WIDTH POLyg DONut FLASH ARC LABEL Undo DRC SHErr RULEs RRoute Abort DEBug

Figura 1.2.15. Subdivisão do circuito de teste em quadrantes e distribuição das estruturas de teste no interior do quadrante.

1.3 O processo de litografia por feixe eletrônico

A contínua busca por circuitos integrados mais complexos, baratos, velozes e de baixo consumo de energia tem levado ao desenvolvimento de técnicas de fabricação cada vez mais complexas e precisas. Dentre os processos de fabricação de um circuito integrado, aquele que mais tem sido pressionado na busca de novas soluções tecnológicas ou no desenvolvimento das soluções convencionais é o processo litográfico.

A litografia deve caminhar sempre à frente dos demais processos, de maneira a não se constituir em um fator limitante no desenvolvimento de novas tecnologias. Como a litografia é que define as dimensões geométricas dos dispositivos a serem fabricados, e como desempenho destes dispositivos é função destas dimensões, a litografia é, portanto, diretamente responsável pela evolução no desempenho dos circuitos integrados. Em outras palavras, a fabricação de memórias de 4 megabits não seria possível hoje, se não tivessem sido desenvolvidas técnicas litográficas que permitissem a definição de estruturas com dimensões submicrônicas.

Dentre estas técnicas destacam-se: O desenvolvimento de lentes com grande abertura numérica, que permitiu o avanço da litografia óptica convencional para dimensões abaixo de 1 micron.

O desenvolvimento dos equipamentos de litografia por feixe eletrônico, feixe iônico, laser e raio-x, que estenderam a fronteira da litografia permitindo já se possa pesquisar dispositivos com dimensões de centésimos de microns. Dentre estes equipamentos, o de litografia por feixe de elétrons tem sido utilizado na última década por quase a totalidade dos fabricantes de máscaras do mundo e por vários fabricantes de circuitos integrados devido a sua grande precisão, versatilidade e velocidade na geração de configurações, quando comparado aos sistemas de geração óptica.

O princípio básico de funcionamento de um equipamento de litografia por feixe eletrônico, consiste na quebra ou agregação das moléculas de um resiste, mudando localmente suas características, através de um feixe de elétrons focalizado, que é defletido e chaveado sob controle de um computador que processa informações correspondentes a configuração a ser escrita.

Um diagrama de blocos completo de um sistema de litografia por feixe eletrônico é mostrado na figura 1.3.1 [2].
Este sistema consiste de quatro subsistemas principais:

- 1) computador de controle do gerador de configurações e interfaces de entrada de dados.
- 2) subsistemas eletrônicos digital/analógico de controle da coluna.
- 3) coluna eletro-óptica.
- 4) sistemas de suporte de coluna eletro-óptica.

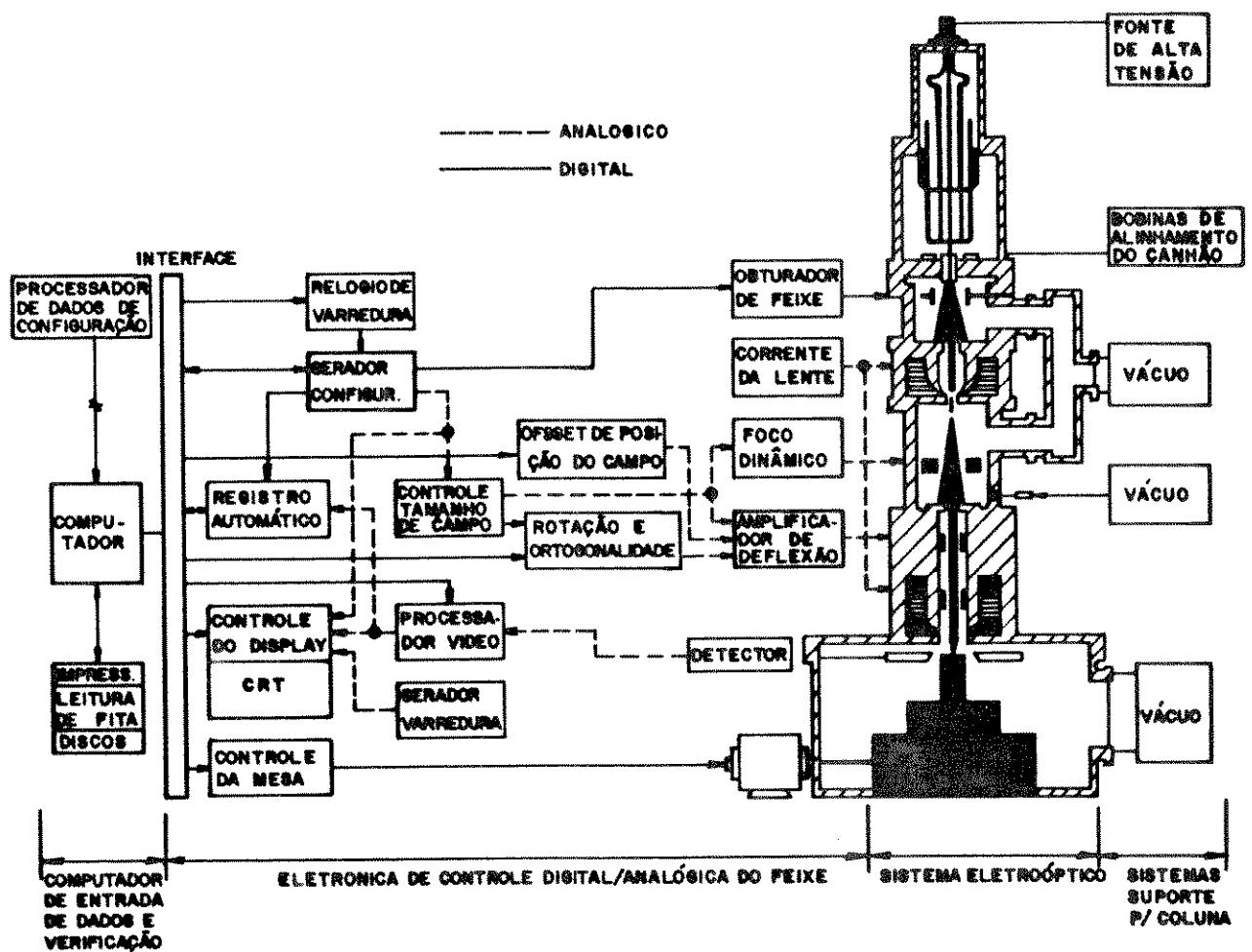


Figura 1.3.1 - Diagrama de blocos de um sistema de litografia por feixe eletrônico.

A unidade computacional de controle é usualmente dividida em dois computadores. O primeiro é responsável pelo recebimento dos dados referentes às configurações a serem escritas em um formato de entrada, e a conversão e o tratamento destes dados no formato próprio para a escrita. O segundo responsável pelo controle dos diversos parâmetros do sistema.

Os subsistemas eletrônicos de controle da coluna são as interfaces entre o computador de controle e a coluna eletro-óptica e fazem as funções de chaveamento, focalização e deflexão do feixe, movimentação da mesa posicionadora, detecção de elétrons secundários para detecção de marcas de alinhamento e de mapeamento de planicidade do substrato.

A coluna eletro-óptica é composta do sistema de geração de elétrons, sistema de focalização do feixe, aberturas para conformação e chaveamento do feixe e sistema de deflexão. Estes elementos podem ser arranjados de diferentes formas dependendo do tipo de feixe desejado. São três os tipos de feixe usualmente empregados em sistemas de litografia por feixe eletrônico com relação a sua seção transversal: redondo (perfil gaussiano), retangular fixo e retangular com dimensões variáveis. Os feixes de seção redonda são utilizados em sistemas de alta resolução e de baixa produção, os de seção retangular fixa são utilizados em sistemas de alta velocidade de escrita, mas por possuirem dimensões da ordem de cinco vezes o diâmetro do feixe redondo, a resolução obtida por este sistema é menor que a obtida pelo feixe redondo.

As colunas que empregam feixe com geometria retangular com dimensão variável, são as que possuem a maior velocidade de escrita combinada com alta resolução, apesar do aumento da complexidade imposta pelo sistema de conformação do feixe que é composto por um sistema de duas aberturas fixas e um sistema de deflexão.

Os sistemas de suporte são compostos pelo sistema de vácuo e fonte de alta tensão. O sistema de vácuo mantém as diversas regiões da coluna com pressões necessárias ao seu funcionamento, e possibilita ciclos de carga e descarga de substratos sem quebrar o vácuo da coluna. A fonte de alta tensão é responsável por fornecer a energia necessária para que os elétrons sensibilizem o resiste. São características destas fontes a faixa de operação de 1KV a 50KV e a alta estabilidade.

Os fatores que afetam diretamente a precisão e repetibilidade do equipamento de litografia por feixe eletrônico estão presentes em cada um dos subsistemas que o constituem.

O sistema emprega software para correções de erro associados com o processo de sensibilização do resiste, através de alterações na estrutura a ser escrita ou nos parâmetros de exposição do feixe. Aberrações do sistema de lentes eletro-ópticas de focalização e do sistema de deflexão são corrigidas através do mapeamento da área de deflexão do feixe e geração de função de correção para os elementos envolvidos. Sistema de medida interferométrico é utilizado para medir a posição real da mesa compensando assim a baixa precisão de posicionamento da mesa. A estabilidade de todos os sistemas mecânicos e eletrônicos é de vital importância pois deles dependem a repetibilidade do equipamento.

É necessário portanto uma caracterização do sistema de litografia com base na avaliação dos erros que afetam o seu funcionamento e que são um resultado dos diversos subsistemas envolvidos e das soluções tecnológicas empregadas em cada caso.

As magnitudes dos diversos erros inerentes do equipamento devem ser obtidas em diversas condições de operação para que se possa obter estratégias de operação que permitem maximizar a utilização do equipamento mesmo quando este é levado ao seu limite de precisão.

A caracterização do equipamento permite também a obtenção da sua "assinatura", ou seja, das características que lhe são peculiares e que possibilitam o acompanhamento do seu desempenho indicando possíveis deteriorações dos sistemas envolvidos, servindo portanto como referência quando da necessidade de manutenção ou calibração.

1.4 A largura da linha

1.4.1 O efeito de proximidade.

Efeito de proximidade é a influência mútua das cargas de elétrons depositadas em um resiste em estruturas vizinhas.[3]

Isto significa que a energia que é absorvida pelo resiste em um dado ponto depende da proximidade de exposições adjacentes. Esta energia é cedida pelos elétrons que ao penetrarem em um material sólido são espalhados pela interação com os átomos da estrutura deste material. Este espalhamento pode ser dividido em duas componentes principais: espalhamento dos elétrons incidentes (espalhamento direto) e o retroespalhamento ou espalhamento dos elétrons com trajetórias de sentido contrário à incidência do feixe que o originou.

A maioria dos elétrons é espalhada com ângulos menores do que 90° (incidentes) da sua direção original. Este efeito contribui para um pequeno aumento no diâmetro do feixe incidente. Alguns elétrons são desviados da direção do feixe incidente de um ângulo maior do que 90° (retroespalhados) tendendo a retornar à superfície do material. O espalhamento, portanto, faz com que o diâmetro efetivo do feixe de elétrons seja maior do que o originalmente esperado, limitando a mínima dimensão que se pode obter em uma estrutura exposta no resiste.

Conforme os elétrons penetram no material, eles vão sofrendo choques elásticos e inelásticos com a estrutura atômica deste material. Os choques elásticos resultam somente na mudança de direção dos elétrons, enquanto que as colisões inelásticas resultam em perda de energia. Portanto, um elétron incidente percorre uma trajetória por dentro do material até perder toda a sua energia resultante de choques inelásticos (que ocorrem tanto para elétrons incidentes como para retroespalhados), ou deixam o material como consequência de retroespalhamento.

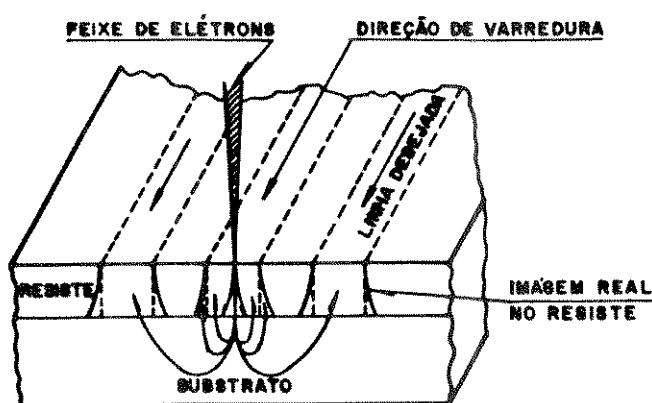


Figura 1.4.1.1 - Ilustração do efeito de espalhamento de elétrons incidentes na exposição de um substrato recoberto de resiste.

O efeito da incidência de um feixe de elétrons em um substrato recoberto de resisto está esquematicamente representado na fig.1.4.1.1. O efeito de aumento na largura de linha causado pelo espalhamento direto é notadamente menor do que a contribuição dos elétrons retroespalhados na largura de linha. Como os elétrons retroespalhados podem viajar distâncias relativamente grandes (alguns microns) dentro do sistema substrato/resiste, uma fração destes contribuem na exposição de configurações que estejam perto da estrutura que está sendo escrita.

O número total de elétrons retroespalhados é caracterizado pelo coeficiente η que é a razão entre o número de elétrons retroespalhados e o número de elétrons incidentes.

O valor de η para substratos recobertos de resisto pode ser calculado através do método de Monte Carlo. Resultados da aplicação deste método no cálculo de η são mostrados na tabela 1.4.1.1.

Substrato	Energia Incidente (KeV)	Espessura do Resistó PMMA (Å)	η	RANGE (μm)
Silício Z=14	20	4000	0,182	4,8
Silício Z=14	10	4000	0,242	2,1
Silício Z=14	20	10000	0,213	4,8
Silício Z=14	25	5000	0,565	3,07*
Silício Z=14	40	5000	0,530	6,91*
Silício Z=14	50	5000	0,462	10,34*
Cobre Z=29	20	4000	0,332	1,6
Ouro Z=79	20	4000	0,538	1,1

TABELA 1.4.1.1 Coeficientes de retroespalhamento para alguns materiais calculados pelo método de Monte Carlo.
[4]

* Dados obtidos da referência [10]

Comparando-se os valores desta tabela, conclui-se que quanto menor o número atômico do material do substrato menor o número de elétrons retroespalhados e consequentemente seus efeitos sobre a dimensão da estrutura a ser exposta.

Outro parâmetro importante na contribuição dos elétrons retroespalhados é a distância sobre a qual esta contribuição é significante. Esta distância é caracterizada pelo range de Bethe que também está apresentado na tabela 1.4.1.1.

A função característica de espalhamento de elétrons foi modelada por Chang [5] como sendo a soma de duas funções gaussianas uma das quais associada com o espalhamento dos elétrons incidentes e a outra com o espalhamento dos elétrons retroespalhados. Outros investigadores têm usado outras funções para aproximar a função de espalhamento [6]. Gaussianas, entretanto, têm propriedades matemáticas que facilitam a convolução da função de espalhamento com o formato real do feixe incidente e permitem ainda a redução do tempo de computação no cálculo da energia total depositada em padrões com alta densidade de configuração, quando comparada com o método de Monte Carlo. Usando resultados obtidos através do método de Monte Carlo, Parikh e Kayser propuseram a seguinte formulação

$$e(r) = K[\exp(-r^2/\beta_f^2) + \eta (\beta_f^2/\beta_b^2) \exp(-r^2/\beta_b^2)]$$

[7].

(1.4.1.1)

onde β_f e β_b são os ranges de Bethe para os elétrons incidentes e retroespalhados respectivamente e η é a razão de contribuição energia total depositada no resiste devido aos elétrons retroespalhados quando comparada com os elétrons espalhados diretamente.

Como a função característica de espalhamento de elétrons como proposta por Chang, sob certas condições não se ajusta aos dados obtidos experimentalmente, foi proposto um modelo com múltiplas gaussianas [8].

$$\sigma(r) = \frac{J \tau}{\pi} \sum_{i=1}^n \frac{\eta_i}{\beta_i} \exp\left(\frac{-r^2}{\beta_i^2}\right)$$

(1.4.1.2)

onde r é a coordenada radial, J a densidade de corrente, τ tempo de residência do feixe, n o número de gaussianas, η_i a energia relativa $\left(\sum_{i=1}^n \eta_i = 1\right)$ e β_i o range da i -ésima componente, respectivamente.

Independente do modelo utilizado para representar o efeito do espalhamento dos elétrons, o resultado deste espalhamento em um sistema resiste/substrato pode ser calculado através da convolução da função característica pontual de espalhamento com a função que representa a figura geométrica a ser exposta [9].

$$E(x,y) = G(x,y) * F(x,y)$$

(1.4.1.3)

onde $E(x,y)$ representa a exposição efetiva no resiste, $G(x,y)$ a função que representa a figura geométrica a ser exposta e $F(x,y)$ a função característica pontual de espalhamento.

Na figura 1.4.1.2 estão apresentadas quatro estruturas geométricas e seus gráficos que representam a energia depositada no resiste obtida por simulação de uma dupla gaussiana como função característica, em convolução com as funções representativas das estruturas geométricas [9].

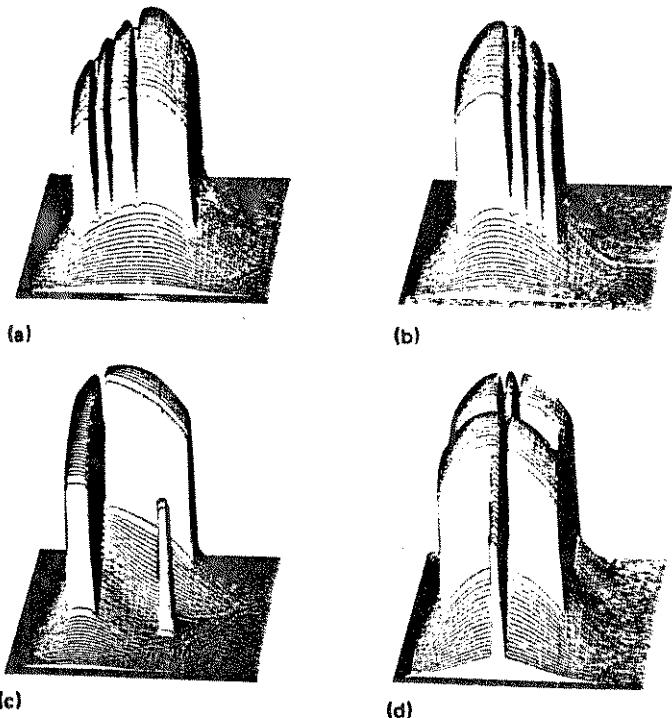
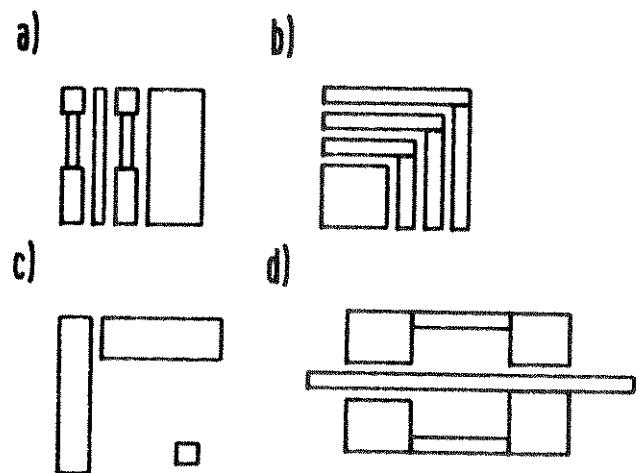


fig. 1.4.1.2

Figura 1.4.1.2 - Um exemplo de estruturas geométricas e seus respectivos gráficos de densidade de energia no resiste obtido através de simulação computacional

Os efeitos de proximidade causados pelo espalhamento dos elétrons são usualmente classificados como sendo de intraproximidade ou de interproximidade.

O efeito de intraproximidade é causado pela subexposição de estruturas estreitas e bordas isoladas devido ao espalhamento de elétrons para fora da área exposta.

O efeito de interproximidade é devido a sobreexposição de um dado elemento causado pela interação dos elétrons espalhados em estruturas próximas.

Tanto o efeito de interproximidade como o de intraproximidade contribuem para deterioração das dimensões de estruturas menores, que estejam dentro dos limites do range efetivo, esta é função do material do substrato, como já explicado, e também da energia dos elétrons. A figura 1.4.1.3. apresenta uma ilustração dos efeitos de interproximidade e intraproximidade.

Quanto maior a energia dos elétrons maior o range efetivo. Por exemplo, no silício estas distâncias são $1,4\mu m$ e $7\mu m$ para 10 e 25 KeV de energia do feixe respectivamente [4].

Como visto, o efeito de proximidade limita as dimensões de estruturas que podem ser escritas por um feixe eletrônico. Uma série de técnicas de correção de efeito de proximidade têm sido desenvolvidas buscando minimizar seus efeitos [10].

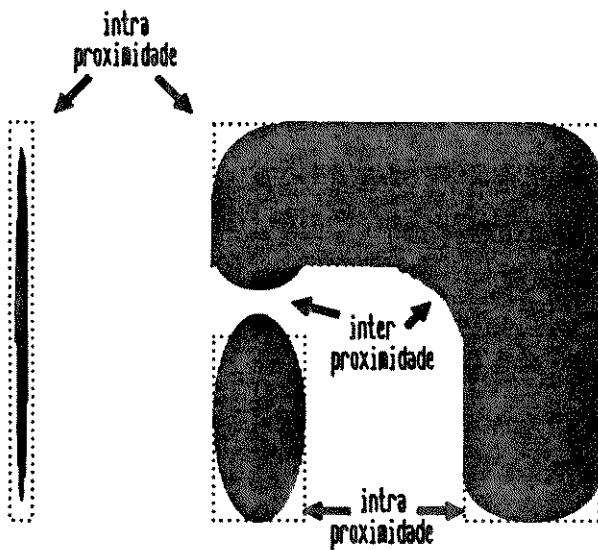


fig 1.4.1.3

Figura 1.4.1.3 - Ilustração esquemática dos efeitos de interproximidade e intraproximidade.

Chang [5] usou com sucesso funções medidas experimentalmente para correção de estruturas "bubble memory".

Parikh [7] desenvolveu um método de otimização individual para cada ponto de exposição em uma estrutura (SPECTRE).

Ckratshamer 1981/1982, Ahmed 1981/1982 e Kern 1982, propuseram um método de correção através do fraturamento da estrutura a ser escrita, em sub-estruturas com doses de exposição diferentes e otimizadas para cada sub-estrutura.

Stephani e T.H. Aachen (1981) utilizaram um processo multi-layer que consiste de duas camadas de resisto separadas por uma camada de SiO₂. Os elétrons são retroespelhados somente na segunda camada de resisto.

Fröschle (1977) e Owen/Rissman (1983) propuseram uma compensação através da deflexão circular defocada do feixe eletrônico (GHOST).

Haslam e McDonald (1987) utilizaram técnicas de deconvolução para obter um padrão de exposição "não-correcta" cujo resultado da convolução com a função característica de espalhamento é a densidade de energia no resisto correspondente ao padrão original.

Otto e Griffth (1988) propõe a correção de proximidade através do particionamento e o cálculo da exposição de cada elemento baseado na posição do elemento com relação à borda da estrutura.

Cada método possui vantagens e desvantagens e são aplicáveis a equipamentos de litografia por feixe de elétrons específicos. Um parâmetro que serve como comparação entre os diversos métodos utilizados é o tempo de processamento computacional necessário para efetuar a correção. Este fator basicamente tem limitado aplicação dos mecanismos de correção em estruturas muito complexas e densas.

1.4.2 Estruturas de teste para avaliação da correção do efeito de proximidade.

Como visto anteriormente o efeito de proximidade dependente dos materiais envolvidos na trajetória dos elétrons, da energia dos elétrons incidentes e da geometria das configurações a serem escritas.

As estruturas de teste para avaliação do efeito de proximidade utilizam geometrias que favorecem o aparecimento deste efeito. Dimensões da ordem de grandeza do range de Bethe, combinações de grandes estruturas próximas de estruturas delgadas, cantos e bordas isoladas ou próximas de outras estruturas, são as combinações geométricas geralmente exploradas. A figura. 1.4.2.1 mostra estruturas comumente utilizadas.

Estruturas simples têm a vantagem da fácil visualização dos efeitos de inter e intraproximidade, mas não são eficientes em testar as estratégias de correção em condições extremas como as que normalmente são encontradas em circuitos de alta escala de integração.

Para a medida da variação da largura de linha induzida pelos efeitos de proximidade nas estruturas mostradas na Figura 1.4.2.1, é necessária a utilização de métodos de microscopia óptica ou eletrônica. Estes métodos têm demonstrado serem lentos, de difícil avaliação estatística, devido ao pequeno número de medidas normalmente utilizado, e também são limitados na precisão e repetibilidade.

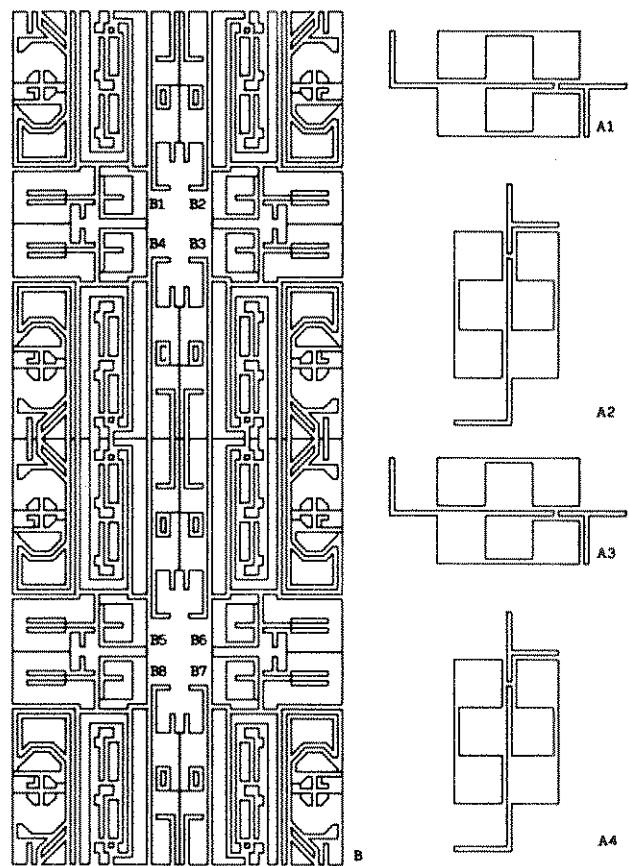


Figura 1.4.2.1 - Estruturas para avaliação do efeito de proximidade

Estruturas de teste elétrico para determinação da largura de linha podem ser utilizadas para medidas do efeito de proximidade em substratos condutores com vantagens sobre os métodos ópticos, devido à facilidade da automação, rapidez, reprodutividade e precisão dos sistemas de medida [12].

A largura de linha W obtida através da medida da resistência R de uma linha de condutor com uma resistência de folha R_s e um comprimento L é expressa por:

$$W = R_s L \cdot \frac{1}{R} \quad (1.4.2.1)$$

Como o comprimento da linha é pouco sensível à variações, a precisão deste método de medida fica condicionada à precisão do método de obtenção da resistência de folha e da resistência da linha.

1.4.3. Estruturas de teste para medida da largura de linha.

A largura de linha é um parâmetro normalmente usado para avaliar e controlar as etapas de fabricação de circuitos integrados. Como as geometrias dos dispositivos têm continuamente sido reduzidas na busca por circuitos mais rápidos, densos, baratos e de menor consumo, alguns dispositivos tornaram-se cada vez mais sensíveis à dimensões, como dispositivos MOS de canal curto.

As tendências atuais do mercado de circuitos integrados apontam na direção da fabricação de pequenas séries de circuitos, demandando pela flexibilidade dos processos de fabricação e consequentemente pela rapidez de ajustes de novos parâmetros de processo e do acompanhamento do processo de maneira a se obter rapidamente respostas às suas variações. Mecanismos de avaliação que permitam a verificação rápida do processo e com a precisão requerida pelas próprias dimensões envolvidas são fundamentais para a implantação destas novas estratégias de fabricação. Estruturas elétricas de avaliação de largura de linha se adaptam perfeitamente a estes requisitos por proporcionarem um método rápido, preciso e barato de avaliação de processo e equipamento.

1.4.4 Método de Van Der Pauw para determinação da resistência de folha.

A resistência de folha de camadas condutoras pode ser obtida através de estruturas tipo ponte [13] ou estruturas Van der Pauw [14]. A estrutura tipo ponte mostrada na figura 1.4.4.1, é constituída de duas linhas de larguras diferentes W_1 e W_2 , de condutância G_1 e G_2 e comprimento L, a resistência de folha pode ser determinada pela equação:

$$R_s = \frac{1}{L} \frac{(W_1 - W_2)}{(G_1 - G_2)} \quad (1.4.4.1)$$

A validade deste método é baseado na afirmação de que a diferença $(W_1 - W_2)$ é uma constante conhecida e que independe da largura de linha absoluta. Esta afirmação é verdadeira uma vez que as linhas foram produzidas identicamente por um mesmo sistema litográfico.

O valor da resistência de folha obtido por este método será dependente da uniformidade do filme na região definida pelas linhas.

A estrutura de Van der Pauw mostrada na figura 1.4.4.2, permite que se determine o valor da resistência de folha em áreas extremamente pequenas, independentemente das variações dimensionais associadas aos processos de litografia e ataque do material condutor que definirá a estrutura.

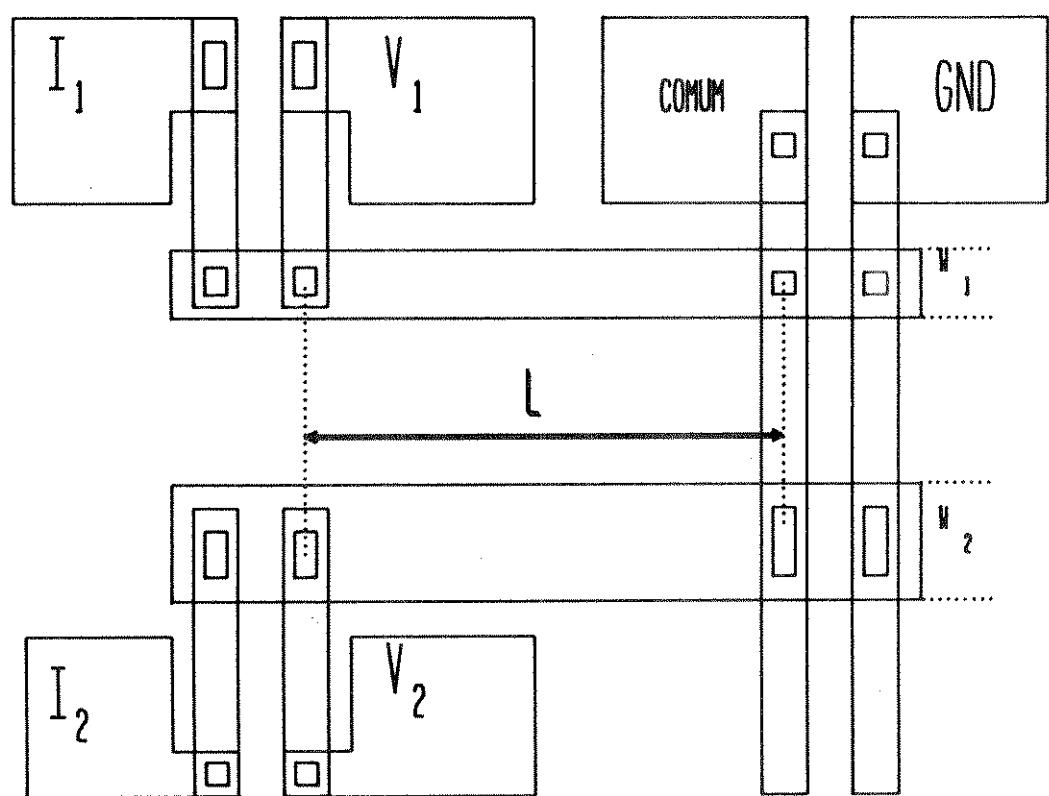


Figura 1.4.4.1 - Estrutura tipo ponte para determinação da resistência de folha.

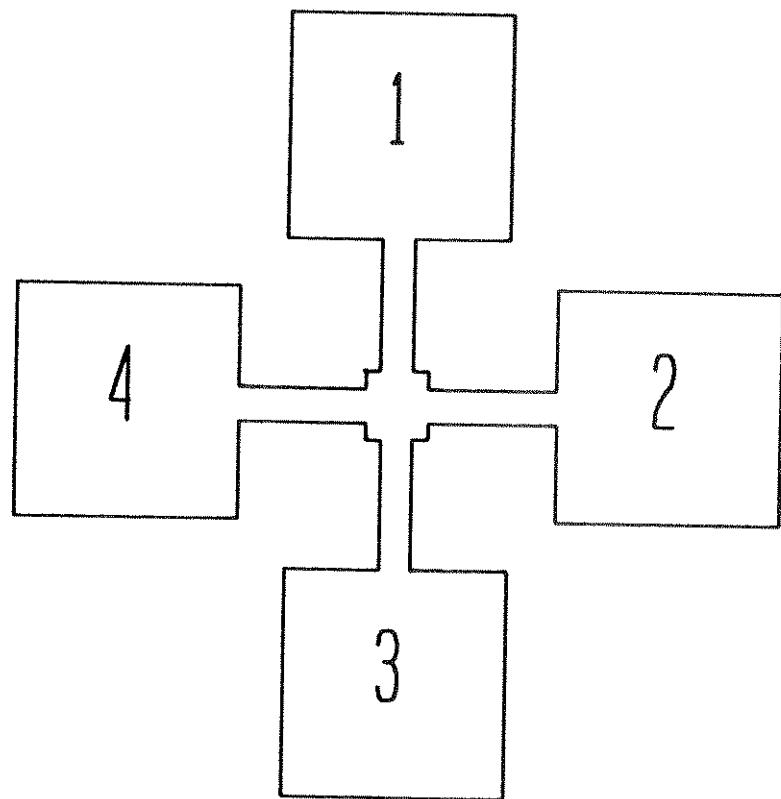


Figura 1.4.4.2 - Estrutura de Van der Pauw

A expressão para o cálculo de resistividade de folha utilizando-se a estrutura de Van der Pauw é dada por:

$$R_s = \frac{\pi}{2 \ln 2} \left[\frac{V_{49}}{I_{12}} + \frac{V_{14}}{I_{29}} \right] \cdot f \left(\frac{V_{49}}{I_{12}} \cdot \frac{I_{29}}{V_{14}} \right) \quad (1.4.4.2)$$

$f \left(\frac{V_{49}}{I_{12}} \cdot \frac{I_{29}}{V_{14}} \right)$ é conhecida como função de Van der Pauw que está mostrada graficamente na figura 1.4.4.3.

Função de Van Der Pauw curva teórica

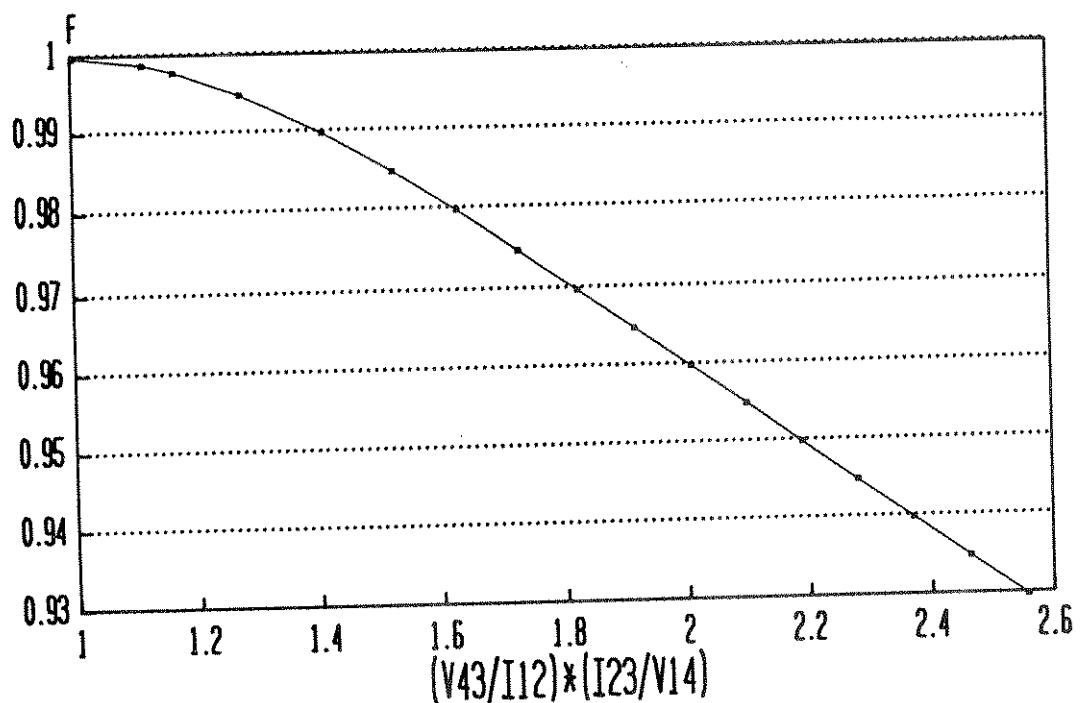


fig 1.4.4.3

Figura 1.4.4.3 - Gráfico da função de Van der Pauw

1.5 O overlay e o Registro

1.5.1. O erro de Overlay e o erro de Registro

Uma das principais aplicações dos equipamentos de escrita por feixe de elétrons é a de definição de etapas litográficas diretamente sobre substratos semicondutores, possibilitando a fabricação de dispositivos e circuitos integrados sem a utilização de máscaras litográficas.

O processo de escrita direta, como é conhecida esta técnica, só é possível devido a capacidade destes equipamentos em alinhar o nível que está sendo escrito, com os níveis anteriormente definidos e já processados. Na fabricação de circuitos integrados são normalmente empregados de 4 a 14 níveis de estruturas superpostas e com a constante tendência de diminuição das dimensões destas estruturas, precisões de alinhamento de $0,05\mu\text{m}$ a $0,20\mu\text{m}$ são necessárias.

Nos equipamentos de feixe de elétrons este nível de precisão é conseguido através da sua utilização no modo de microscópio eletrônico de varredura (SEM) para detecção de marcas de alinhamento gravadas previamente no substrato.

As marcas de alinhamento são simplesmente variações na topografia do substrato que mostram diferentes características de retroespalhamento de elétrons quando varridas por um feixe de elétrons.

Estas diferentes características de retroespalhamento podem ser causadas pela varredura do feixe sob uma marca feita de um material com número atômico muito diferente do substrato (Au sobre Si por exemplo) ou pela varredura de uma marca de alinhamento com uma borda acentuada. Este efeito é conhecido como contraste topológico e é resultante da dependência do coeficiente de retroespalhamento com o ângulo de incidência do feixe em relação ao substrato.

Estes elétrons retroespelhados são captados por um sensor, e transformados em um sinal de vídeo correspondente a marca. Este sinal é processado e resulta na determinação das coordenadas x e y da marca de alinhamento, que serão usadas como referência para posicionamento das estruturas a serem escritas. A deteção de um conjunto de marcas de alinhamento permite também a correção de erros de ampliação, ortogonalidade, translação e rotação causados pela distorção do substrato devido aos sucessivos processamentos físico-químicos e imprecisões no sistema mecânico de deslocamento do substrato. Normalmente dois esquemas de alinhamento são utilizados: global, que alinha o nível a ser escrito a um sistema de coordenada para todo o substrato e individual que alinha cada circuito a ser escrito em um sistema próprio de coordenadas. Para cada esquema de alinhamento são necessárias três marcas para a determinação dos componentes do erro de alinhamento.

Os equipamentos de escrita por feixe eletrônico possuem rotinas que permitem a deteção automática das marcas de alinhamento, tanto no modo global como individual e também as correções automáticas dos erros de ampliação, ortogonalidade, translação e rotação.

A diferença entre a posição das estruturas definidas em um nível anterior ao exposto, e a posição correspondente no sistema de coordenadas do nível atual, adicionado a resolução de posicionamento do sistema feixe/mesa, é conhecido como erro de registro que pode ser medido através do desalinhamento de duas estruturas superpostas, definidas no substrato em dois níveis diferentes de litografia.

O erro de registro difere do de overlay por representar o erro de alinhamento entre níveis gravados no substrato semicondutor, enquanto que o erro de overlay representa o erro de alinhamento entre níveis gravados na máscara. Basicamente o erro de registro é devido ao equipamento de escrita por feixe de elétrons enquanto que o erro de overlay, como dito, engloba os erros devidos ao equipamento de geração da máscara adicionados ao erro da máscara.

Quando o erro de registro é medido em um substrato semicondutor que foi gravado por litografia óptica através de equipamentos de alinhamento de máscara por contato ou proximidade, ou ainda por repetidoras de passo, o erro englobará o erro de overlay e ainda o erro do equipamento de alinhamento e o erro do operador.

Portanto por não incluir os erros de alinhamento devido ao operador e o erro da máscara, o erro de registro em substratos semicondutores gravados por litografia de feixe de elétrons é menor do que os encontrados em substratos gravados por litografia óptica. Pelo mesmo motivo, o erro de registro medido em lâminas produzidas por escrita direta por feixe eletrônico reflete a precisão do sistema de posicionamento do equipamento, do sistema de alinhamento automático, bem como da estratégia adotada na detecção das marcas de alinhamento e da eficiência do software de correção utilizado.

Por simplificação podemos generalizar a definição de erro de registro como sendo o erro de overlay medido diretamente sobre a lâmina.

Os métodos de medida empregados na avaliação do erro de overlay são basicamente os mesmos empregados na avaliação do erro de registro.

A medida da diferença da superposição de duas imagens correspondentes a dois níveis de máscara projetadas por um sistema óptico é o método normalmente empregado para medida do erro de overlay. Os equipamentos que utilizam este método requerem alta precisão de posicionamento de cada uma das máscaras o que é conseguido através da utilização de duas mesas posicionadoras de precisão suportadas por uma terceira mesa que permite o deslocamento em grandes extensões, proporcionando a possibilidade da medida do erro em vários pontos da máscara.

O processamento digital de imagens permite que a imagem de um nível de máscara seja armazenado para posterior comparação com a imagem de outro nível e os erros de posicionamento entre elas podem ser medidos e os resultados podem ser dados de maneira gráfica.

1.5.2 A avaliação do erro de overlay

Uma geração de circuitos integrados é geralmente caracterizada por sua regra de projeto, que é uma quantidade que descreve mais de um parâmetro de um produto. Quantitativamente a regra do projeto é idêntica a largura de linha mínima, ou seja, a menor geometria a ser gravada.

A regra do projeto implica não somente que as configurações podem ser gravadas com uma tolerância de largura de linha definida, mas também que elas devem estar precisamente situadas em posições pré-determinadas por configurações gravadas na lâmina de silício em um nível precedente. A coincidência estatística destas posições é chamada de sobreposição de um nível em relação ao outro, ou simplesmente superposição ou "overlay" [17].

O erro de superposição quantifica a dispersão do deslocamento dos elementos de uma configuração gravada em uma máscara. Estes deslocamentos podem variar continuamente ou descontinuadamente ao longo da área da máscara. Erros contínuos são deslocamentos de elementos da configuração que variam suavemente numa dada região. Estes erros podem ser causados por imperfeições no gerador de configurações (devido a erros de escalamento ou distorções das lentes eletromagnéticas e/ou varredura), ou eles podem ser introduzidos durante o processamento da máscara.

Erros descontínuos, são deslocamentos isolados dos elementos da configuração (causados por interferências eletromagnéticas ou vibrações mecânicas no gerador de configurações), ou deslocamentos relativos de toda uma região da máscara. Em equipamentos de feixe eletrônico erros descontínuos são devidos a erros de posicionamento do campo de escrita.

Os erros que efetam o overlay podem ser causados por imperfeições no equipamento, na máscara e como são cumulativos e independentes entre si, o valor do erro de overlay pode ser expresso por:

$$\varepsilon_{ov} = \sqrt{\varepsilon_E^2 + \varepsilon_M^2}$$

onde ε_{ov} = erro de overlay

ε_E = erro do equipamento

ε_M = erro da máscara

O erro da máscara está ligado diretamente ao erro induzido por variações dimensionais devido a variações de temperatura. Os materiais utilizados normalmente na fabricação de máscaras são: vidro borossilicato, "soda lime" e quartzo natural ou sintético. A tabela 1.5.2.1 apresenta os coeficientes de expansão térmica α para estes materiais e o erro de máscara ε_M por grau de diferença entre a temperatura em que a máscara foi fabricada e a temperatura de utilização da máscara para uma máscara de 5".

Material	$\alpha (10^{-6}/K)$	$\varepsilon_M (\mu m/\text{ }^\circ\text{C})$
Green soda lime	9.4	1.19
White crown soda lime	9.3	1.18
Borossilicato	3.7	0.47
Quartzo natural	~0.5	0.06
Quartzo sintético	0.5	0.06

Tabela 1.5.2.1 Coeficientes de expansão térmica para vários materiais empregados na fabricação de máscaras.

1.5.3. Estruturas de teste para avaliação do erro de overlay.

Estruturas empregadas para avaliação do erro de overlay ou registro se subdividem em estruturas de avaliação óptica e estruturas de avaliação elétrica.

Estruturas de avaliação óptica consistem basicamente de verniers e de estruturas "box-within-a-box".

Estruturas tipo vernier podem ser empregadas para avaliação do erro de registro. Elas são constituídas de uma escala e um índice graduados. O deslocamento relativo entre a escala e o índice pode ser lido diretamente na graduação. Estas estruturas apresentam como vantagem a simplicidade e exigem sómente a utilização de um microscópio óptico para a leitura dos verniers. Como desvantagens elas apresentam baixa resolução, normalmente metade da menor divisão que pode ser lida e que está restrita a menor dimensão que pode ser gravada pelo processo litográfico.

Estruturas "box-within-a-box" são formadas por dois quadrados de tamanhos diferentes gravados cada um em um nível de máscara, de maneira ao menor deles ficar circunscrito ao maior. O erro de overlay é medido utilizando-se um equipamento para medida de largura de linhas que mede a separação entre os dois quadrados, para cada lado dos quadrados. Se não existir erro de overlay, os quadrados serão concêntricos e as separações medidas apresentarão o mesmo valor.

Estruturas elétricas são empregadas para medida do erro de registro em substratos condutores. O procedimento normalmente empregado consiste de duas etapas, uma para cada nível a ser comparado. Na primeira etapa define-se a primeira parte da estrutura em substrato isolante recoberto com uma camada condutora empregando-se a primeira máscara, e na segunda etapa, através da segunda máscara, faz-se a deposição adicional de camada condutora para formação da estrutura de avaliação, ou faz-se a remoção de parte da estrutura previamente definida.

Um exemplo de estrutura de avaliação de erro de registro utilizando-se método de deposição adicional de camada condutora é mostrado na figura 1.5.3.1, que emprega a variação da resistência em função da posição dos contatos em uma estrutura Van Der Pauw.[18].

Um exemplo de estrutura de avaliação do erro de registro pelo método da remoção da camada condutora é mostrado na figura 1.5.3.2. Este procedimento define linhas condutora cujas larguras são função do alinhamento entre os dois níveis de máscara, consequentemente as resistências destas linhas são função do erro de registro.

A utilização de uma ou de outra solução depende do processo disponível e da precisão requerida.

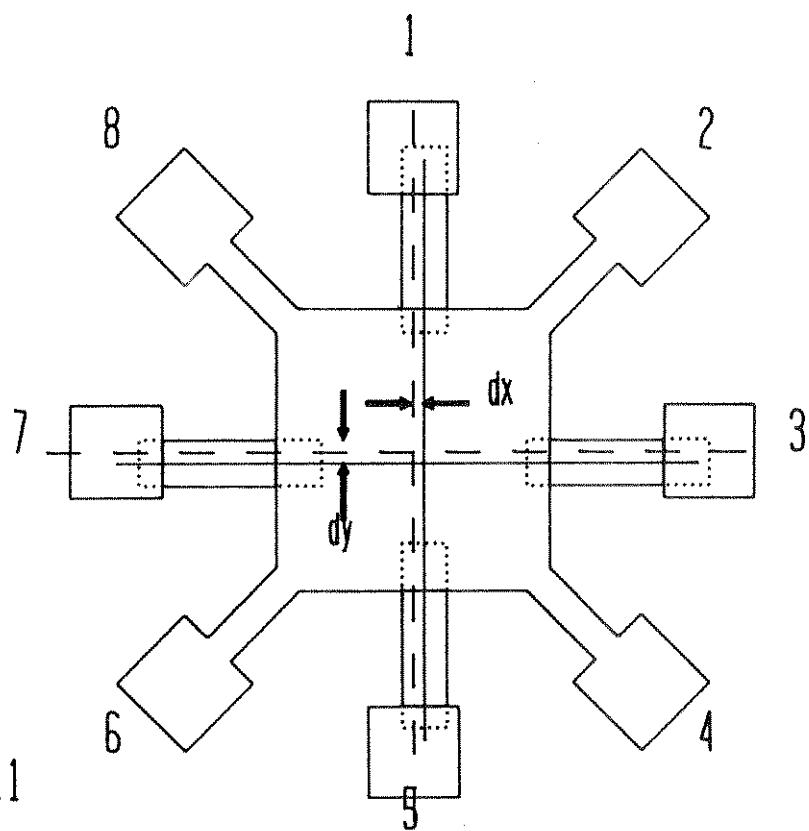


fig 1.5.3.1

Figura 1.5.3.1 Estrutura de avaliação de erro de registro utilizando-se método de deposição adicional de camada condutora

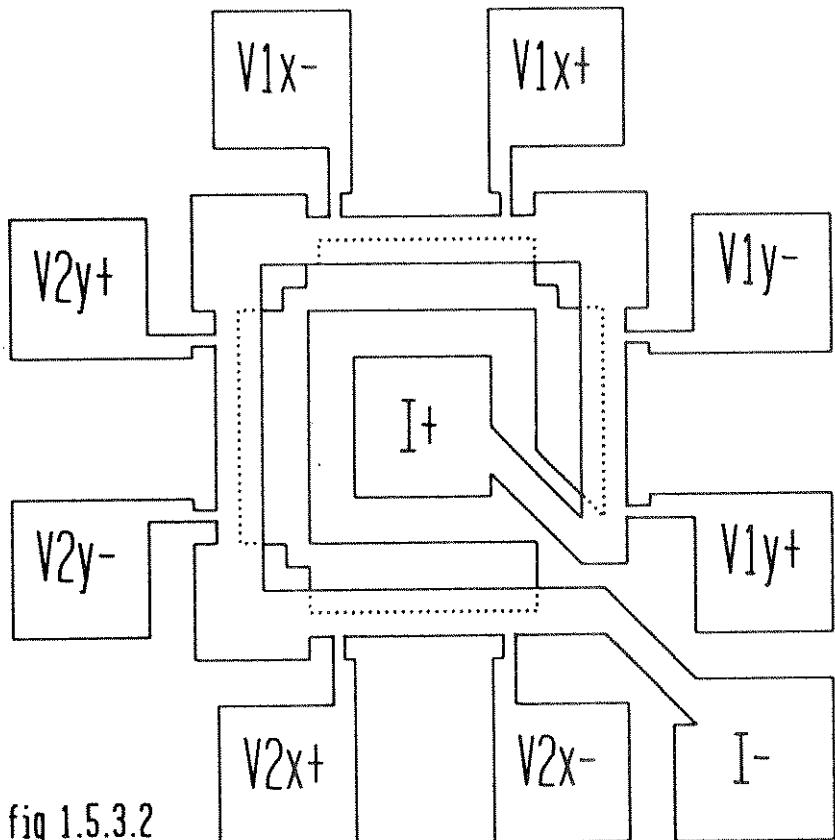


fig 1.5.3.2

Figura 1.5.3.2 Estrutura de avaliação do erro de registro pelo método da remoção da camada condutora

1.6 A densidade de defeitos

O efeito da contaminação em dispositivos de alta integração frequentemente leva a um desvio na performance elétrica destes dispositivos. Um condutor em curto ou interrompido pode significar a falha de um componente, sendo fatal para o circuito integrado como um todo.

Defeitos presentes em uma máscara, grandes o suficiente para serem resolvidos pelo processo fotolitográfico, serão transferidos para a lâmina e causam defeitos de funcionamento nos dispositivos.

Alguns destes defeitos podem ser fatais. Defeitos adicionais serão gerados durante as etapas de litografia usadas para transferir as geometrias presentes na máscara. Do total de etapas de processo necessárias para a fabricação de circuitos integrados, as várias etapas litográficas exibem o rendimento mais baixo. Se considerarmos o rendimento de todas as etapas litográficas juntas, podemos concluir que a etapa litográfica é dominante na determinação do rendimento do processo de fabricação. A densidade de defeitos na máscara é um fator extremamente importante nos processos de produção em microeletrônica.

A densidade de defeitos e o rendimento podem ser relacionados através do modelo proposto por Murphy [19].

Modelo de rendimento de Murphy

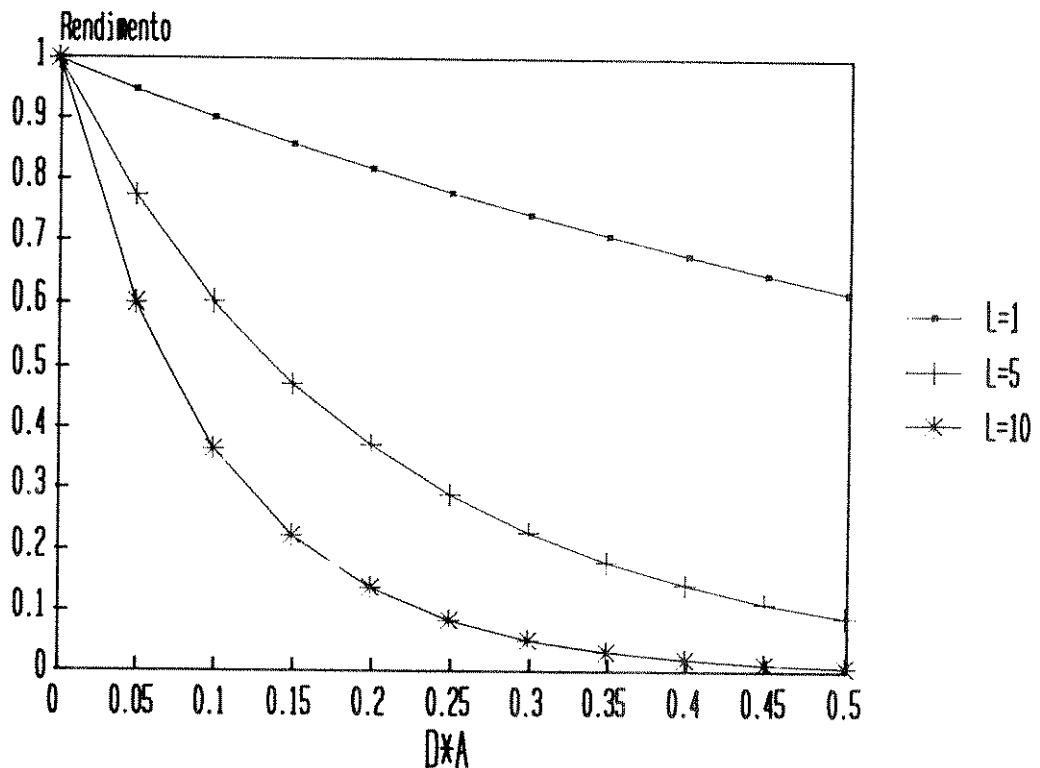


fig. 1.6.1

Figura 1.6.1 Representação gráfica do modelo do rendimento proposto por Murphy.

Este modelo permite predizer o rendimento cumulativo de um processo de L níveis de máscaras. A figura 1.6.1 mostra o modelo proposto por Murphy representado graficamente e parametrizado em função do número de níveis de máscaras onde $x = D * A$, sendo D a densidade de defeitos por nível, e para simplificação todos os níveis possuem a mesma densidade de defeitos, e A a área do circuito integrado. Podemos notar da figura 1.6.1., que o rendimento decresce rapidamente com o aumento do número de máscaras, para um dado valor fixo de X. Num processo CMOS que apresenta de 10 a 14 níveis de máscaras, a densidade de defeitos em cada etapa litográfica é um parâmetro muito importante na determinação do rendimento final do produto.

Com a utilização da escrita direta por feixe eletrônico como etapa litográfica, elimina-se a porção de redução do rendimento devido a máscara, tornando-se os defeitos introduzidos por contaminação e manuseio durante as etapas de deposição do eletroresiste e no posterior processamento pós exposição, os determinantes na redução do rendimento final do produto.

Apesar de existirem excelentes ferramentas de detecção de partículas tais como contadores de partícula do ar, em líquidos e na superfície da lâmina, deve-se procurar por métodos de primeira ordem que possibilitem acessar os efeitos da contaminação na funcionalidade elétrica e consequentemente no rendimento.

As estruturas elétricas podem ser utilizadas na detecção de defeitos que alterem suas propriedades. A condutância é uma propriedade que pode ser explorada na detecção de defeitos fatais, pois estes se manifestam principalmente pela interrupção de uma trilha condutora ou pelo curto-circuito entre duas trilhas condutoras adjacentes. Estruturas elétricas que possibilitem a detecção de defeitos fatais são de fundamental importância na engenharia de processo para a localização das fontes de contaminação, bem como das etapas de processo mais sujeitas a ocorrência de defeitos.

CAPÍTULO 2

A LARGURA DE LINHA E O DESEMPENHO DO PROCESSO DE LITROGRAFIA

2.1 Estruturas de resistência tipo ponte

Um resistor tipo ponte é composto por uma linha condutora de largura W onde se faz quatro contatos, dois externos onde é aplicada uma corrente I , e dois internos onde o potencial V é medido, fig.2.1.1. Sendo L a distância centro a centro dos contatos internos, pode-se calcular a largura de linha pela seguinte expressão:

$$W = R_s \cdot L \cdot \frac{I}{V} \quad (2.1.1)$$

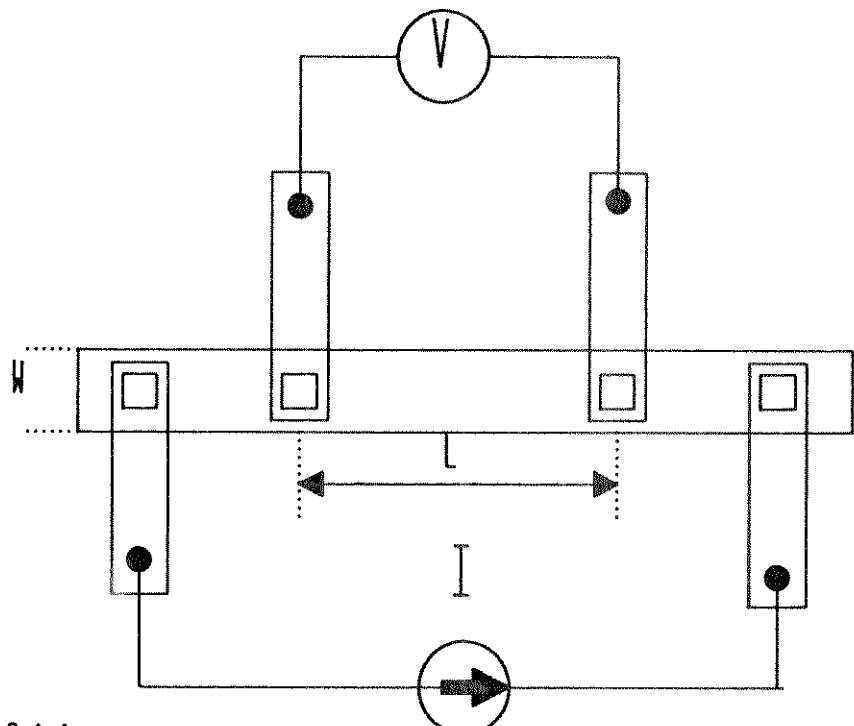


fig. 2.1.1

Figura 2.1.1 - Resistor tipo ponte utilizado para determinação da largura de linha.

2.2 Estrutura de teste proposta

A largura de linha é um parâmetro que é comumente empregado para avaliar e controlar as etapas de processo de fabricação de circuitos integrados, pois está diretamente associada ao desempenho destes circuitos tanto do ponto de vista das características elétricas, tais como frequência de operação, potência consumida e etc., como também das características geométricas como quantidade de dispositivos integráveis por unidade de área. Portanto métodos precisos e rápidos de avaliação da largura de linha são de vital importância para a depuração de processos de fabricação.

Dentre os muitos fatores de processo que afetam a largura de linha, os processos litográficos, que definem a largura de linha ou dimensão crítica, são os mais importantes.

Atualmente os processos litográficos limitam a mínima dimensão a ser escrita no circuito integrado. Novas técnicas tais como litografia de Raio-X, feixe eletrônico, ultravioleta profundo e litografia por feixe ions, têm sido utilizadas na busca de dimensões cada vez menores.

Estruturas que possam avaliar o desempenho tanto dos equipamentos quanto dos processos litográficos podem ser de grande ajuda na evolução das técnicas de litografia.

A estrutura de teste proposta, apresentada na figura 2.2.1, consiste basicamente de uma estrutura de Van der Pauw, associada a estruturas tipo ponte. Cada braço da cruz que caracteriza a estrutura Van der Pauw forma um resistor tipo ponte. O conjunto de braços na direção X contém dois resistores em ponte com larguras de linha W_1 e W_2 . O mesmo acontece para os braços na direção Y.

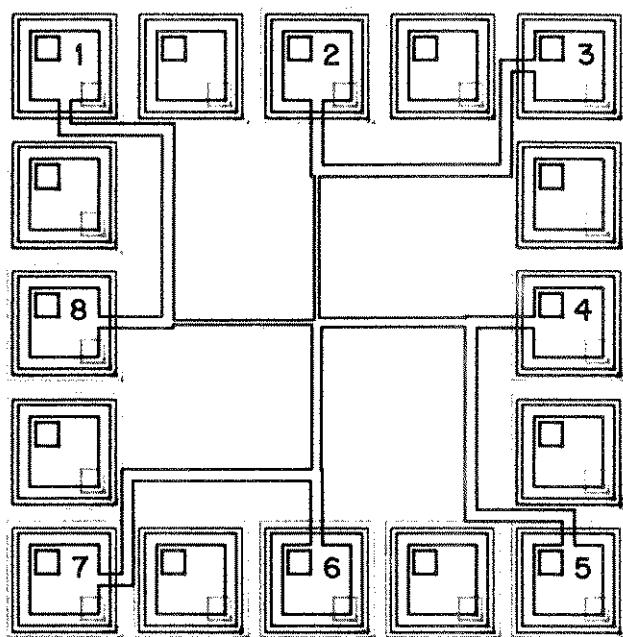


Figura 2.2.1 - Estrutura de teste proposta para avaliação da largura de linha.

Com esta estrutura é possível obtermos a resistência de folha R_s da camada onde está gravada a estrutura, diretamente na região onde está sendo avaliada a largura de linha. O valor da resistência de folha será dada por:

$$R_s = \frac{\pi}{\ln 2} \left(\frac{R_{86,24} + R_{28,46}}{2} \right) f \left(\frac{R_{86,24}}{R_{28,46}} \right) \quad (2.2.1)$$

$$\text{onde } R_{86,24} = \frac{V_{86}}{I_{24}} \quad \text{e} \quad R_{28,46} = \frac{V_{28}}{I_{46}}$$

As larguras de linha podem ser calculadas segundo a seguinte expressão:

No eixo X,

$$W_{1X} = R_s L_1 \frac{I_{84}}{V_{12}} \quad (2.2.2)$$

$$W_{2X} = R_s L_2 \frac{I_{84}}{V_{85}} \quad (2.2.3)$$

no eixo y,

$$W_{1Y} = R_s L_1 \frac{I_{26}}{V_{54}} \quad (2.2.4)$$

$$W_{2Y} = R_s L_2 \frac{I_{26}}{V_{87}} \quad (2.2.5)$$

Os valores nominais das larguras de linha obtidas permitem avaliar primeiramente se o conjunto de fatores, equipamentos, processo litográfico e processo de ataque, obedecem às especificações previstas para este processo, produzindo larguras de linha com as dimensões definidas no projeto.

A diferença nas larguras de linha causada pelo equipamento litográfico pode ser avaliada nas direções x e y, podendo-se deduzir destes valores se existem distorções nos sistemas de geração de configurações.

Outra informação importante pode ser extraída da estrutura proposta, a variação da largura de linha induzida pelo processo em cada direção.

A expressão que possibilita o cálculo desta variação é derivada de expressão para resistor em ponte [15].

Se ΔW é a variação induzida pelo processo e R_1 e R_2 as resistências para cada largura de linha, então:

$$R_s = \frac{W_1 + \Delta W}{L_1} \cdot R_1 \quad (2.2.6)$$

$$R_s = \frac{W_2 + \Delta W}{L_2} \cdot R_2 \quad (2.2.7)$$

portanto,

$$\Delta W = \frac{\frac{W_1 R_2 L_2 - W_2 R_1 L_1}{L_1 R_2} - \frac{W_2 R_1 L_1}{L_2 R_1}}{\frac{W_1 R_2 L_2}{L_1 R_2} - \frac{W_2 R_1 L_1}{L_2 R_1}} \quad (2.2.8)$$

A estrutura proposta permite a avaliação de ΔW na direção x e na direção y.

2.3 O erro do método de medida da largura de linha nas estruturas de testes elétricos

Como visto, o método de determinação de larguras de linha através de testes elétricos utiliza dois procedimentos distintos, a determinação da resistência de folha do filme condutor através de estruturas tipo Van der Pauw, e a determinação da largura de linha propriamente através de estruturas em ponte.

As medidas da resistência de folha pelo método de Van der Pauw possuem um erro inherente que pode ser estimado da figura 2.3.1 [16].

Para a estrutura proposta, as razões entre a largura de linha e o tamanho do braço da cruz A são de 15 para W_1 e 30 W_2 . Portanto o erro normalizado estimado da curva da figura 2.4.1 pode ser considerado desprezível.

Erro normalizado de Rs Estrutura de Van Der Pauw

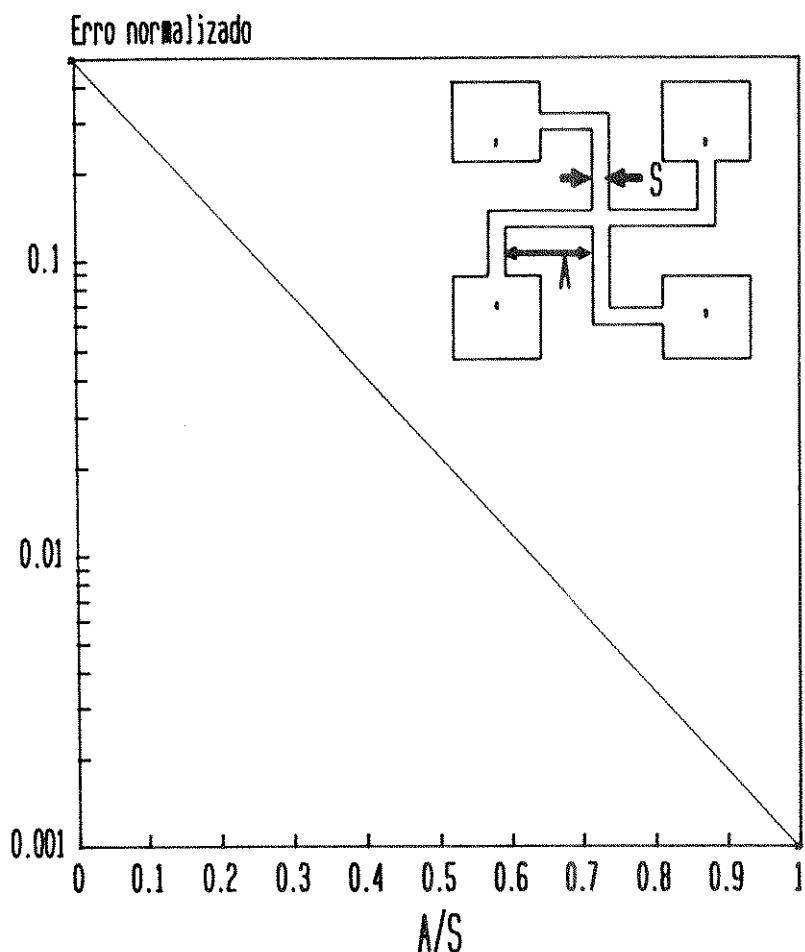


fig. 2.3.1

Figura 2.3.1 - Erro normalizado da resistência de folha devido ao comprimento do braço de contato para estrutura cruz grega.

Além do erro inherente à estrutura de Van der Pauw, existe o erro resultante do processo de medida de tensão e da corrente que é aplicada na estrutura. Supondo-se que o erro de medida da fonte de corrente seja σI e erro do medidor de tensão σV , o erro da medida da resistência de folha pode ser calculado, sendo a resistência expressa pela equação abaixo:

$$R_s = \frac{\pi}{2I\ln 2} \left(\frac{V_1}{I_1} + \frac{V_2}{I_2} \right) \quad (2.3.1)$$

O erro total será expresso por:

$$\sigma_{R_s} = \sqrt{\sigma_{(V_1/I_1)}^2 + \sigma_{(V_2/I_2)}^2} \quad (2.3.2)$$

O erro do cálculo de V/I é:

$$\sigma_{(V/I)} = \frac{V}{I} \sqrt{\frac{\sigma^2 V}{V^2} + \frac{\sigma^2 I}{I^2}} \quad (2.3.3)$$

Substituindo-se:

$$\sigma_{R_s} = \sqrt{\left(\frac{V_1}{I_1}\right)^2 \left(\frac{\sigma^2 V_1}{V_1^2} + \frac{\sigma^2 I_1}{I_1^2}\right) + \left(\frac{V_2}{I_2}\right)^2 \left(\frac{\sigma^2 V_2}{V_2^2} + \frac{\sigma^2 I_2}{I_2^2}\right)} \quad (2.3.4)$$

Como a fonte de corrente e o medidor de tensão são os mesmos e as tensões V_1 e V_2 apresentam valores muito próximos, se a corrente injetada for $I = I_1 = I_2$, podemos reduzir a equação do erro para:

$$\sigma_{R_s} = \sqrt{2} \cdot \frac{V}{I} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2} \quad (2.3.5)$$

Utilizando-se ainda as considerações acima e a inigualdade:

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_i}{i}\right)^2} < \frac{\sigma_v}{v} + \frac{\sigma_i}{i} \quad (2.3.6)$$

que dá resultados conservativos, isto é com erro em excesso, e substituindo na equação de R_s , obtemos:

$$R_s = \frac{\Pi}{\ln 2} \quad \frac{v}{i} \longrightarrow \frac{v}{i} = \frac{R_s \ln 2}{\Pi} \quad (2.3.7)$$

$$\frac{\sigma_{R_s}}{R_s} = \frac{\sqrt{2 \ln 2}}{\Pi} \cdot R_s \quad \sqrt{\left(\frac{\sigma_v^2}{v}\right) + \left(\frac{\sigma_i^2}{i}\right)} \quad (2.3.8)$$

$$\frac{\sigma_{R_s}}{R_s} < \frac{\sqrt{2 \ln 2}}{\Pi} \left(\frac{\sigma_v}{v} + \frac{\sigma_i}{i} \right) \quad (2.3.9)$$

ou seja

$$\frac{\sigma_{R_s}}{R_s} < 0,31 \quad \left(\frac{\sigma_v}{v} + \frac{\sigma_i}{i} \right) \quad (2.3.10)$$

O erro relativo da medida de resistência de folha utilizando-se teste elétrico é menor que trinta por cento da soma dos erros relativos da medida de corrente e de medida de tensão.

Supondo-se que numa medida de resistência de folha utiliza-se um voltímetro com resolução de $1\mu V$ medindo tensões de $20mV$ e uma fonte de corrente de $5mA$ com uma resolução de $1\mu A$ obtem-se :

$$\frac{\sigma_{R_s}}{R_s} < 0,31 \left(\frac{1 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-9}} + \frac{1 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-9}} \right) \quad (2.3.11)$$

$$\frac{\sigma_{R_s}}{R_s} < 7,7 \times 10^{-6} \quad (2.3.12)$$

ou ainda

$$\sigma_{R_s} < 7,7 \times 10^{-6} \times R_s \quad (2.3.13)$$

$$\sigma_{R_s} < 1,36 \times 10^{-4} \quad (2.3.14)$$

O erro da determinação da largura de linha utilizando estruturas em ponte pode ser derivado da expressão para o cálculo da largura de linha.

$$W = R_s \cdot L \cdot \frac{I}{V} \quad (2.3.15)$$

$$\frac{\sigma_W}{W} = \sqrt{\left(\frac{\sigma R_s}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{\sigma L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\sigma V}{V}\right)^2} \quad (2.3.16)$$

utilizando-se as considerações mencionadas no cálculo do erro relativo da medida de resistência de folha podemos estimar:

$$\left(\frac{\sigma_W}{W}\right)^2 = \left(7,7 \times 10^{-6}\right)^2 + \left(2 \times 10^{-4}\right)^2 + \left(5 \times 10^{-5}\right)^2 + \left(\frac{\sigma L}{L}\right)^2 \quad (2.3.17)$$

$$\left(\frac{\sigma_W}{W}\right)^2 = 4,3 \times 10^{-8} + \left(\frac{\sigma L}{L}\right)^2 \quad (2.3.18)$$

2.4 Os procedimentos das medidas de resistência de folha e análise dos resultados obtidos.

O valor da largura de linha em estruturas tipo ponte é expressa por:

$$W = R_s \cdot L .. - \frac{I}{V}$$

Portanto para a obtenção da largura de linha é necessário medirmos a resistência de folha.

O valor da resistência de folha foi medido nas camadas de polissilício, metal 1 e difusão através de estruturas Van Der Pauw convencionais, e as resistências de folha do polissilício e do metal 1 também foram medidas nas estruturas propostas.

A resistência de folha foi obtida na estrutura proposta e nas estruturas Van Der Pauw através da média das resistências medidas nos dois esquemas mostrados na figura 2.4.1.

Para a obtenção da resistência de folha foi utilizado um equipamento HP 4145B "Semiconductor Parameter" e dois Multímetros HP 3478. O HP4145B é um equipamento que possui um conjunto de quatro fontes/monitores programáveis (SMU's) que podem ser configuradas como fonte de corrente/monitor de tensão ou fonte de tensão/monitor de corrente. Adicionalmente possui dois monitores de tensão (SM's) e duas fontes de tensão (VM's) independentes.

Estes equipamentos foram configurados conforme a figura 2.4.2. Esta montagem permitiu que se fizesse a medida da resistência de folha na estrutura de Van de Pauw formada no cruzamento das linhas no centro da estrutura, obtendo-se a troca de posições da fonte de corrente e medidor de tensão pela programação do equipamento HP4145B.

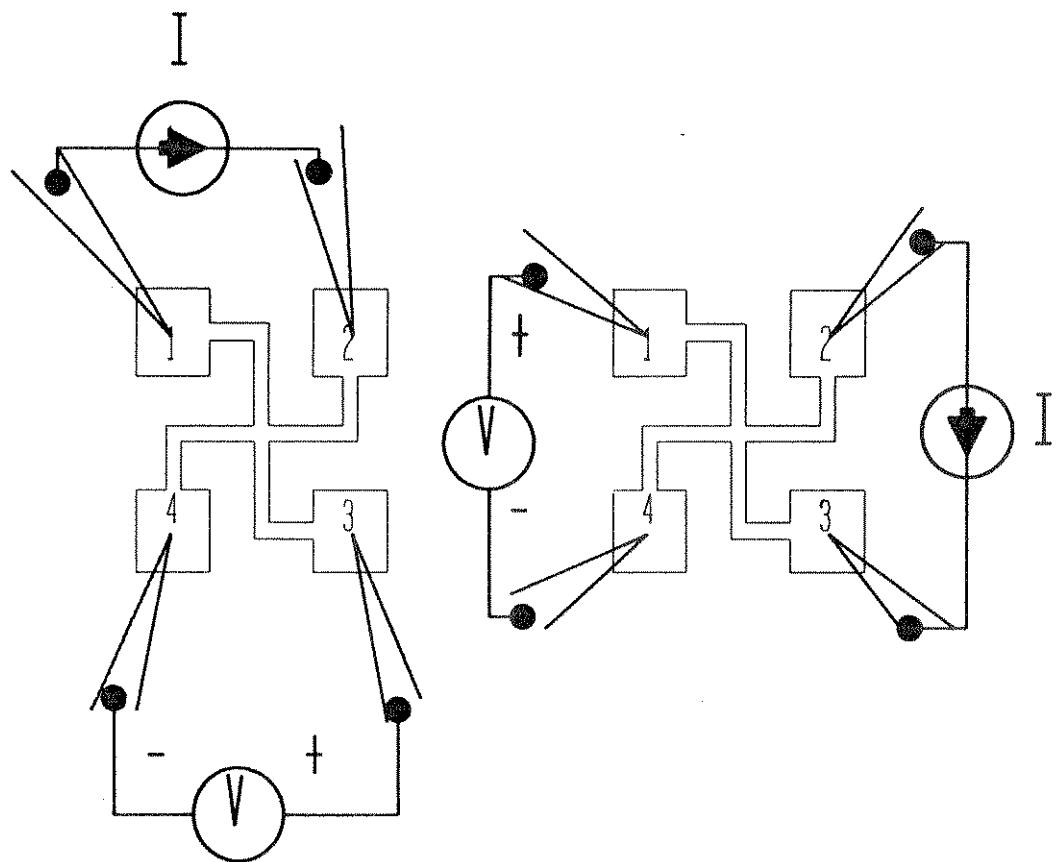


Figura 2.4.1 Esquemas utilizados na medida da resistência de folha em estruturas Van Der Pauw.

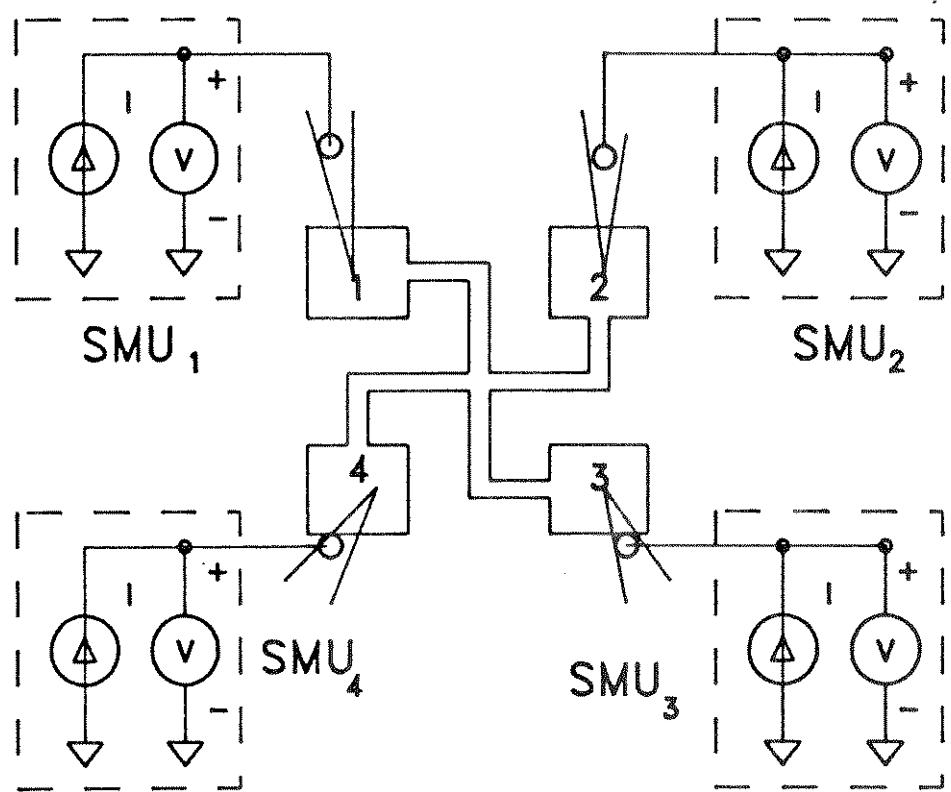


Figura 2.4.2 Configuração utilizada na determinação da resistência de folha pelo método de Van Der Pauw.

Os medidores de tensão HP 3478 foram utilizados devido a sua resolução na escala de milivolts ser de $1\mu V$ e também possuir impedância de entrada de $10^{10}\Omega$. Os medidores de tensão do equipamento HP4145B possuem baixa resolução para esta faixa de tensão o que impossibilitou a sua utilização.

As medidas foram feitas em duas etapas, a saber:

1a. A fonte SMU1 é programada como fonte de corrente com um valor nominal de $4.532 \text{ mA} \pm 1 \mu\text{A}$. A fonte SMU2 é programada como fonte de tensão com valor nominal de $0 \text{ V} \pm 1 \text{ mV}$, o monitor de corrente de SMU2 indica, portanto, a corrente que efetivamente circulou pela estrutura.

As fontes SMU3 e SMU4 foram programadas como fontes de corrente com valores nominais de $10 \text{ pA} \pm 1 \text{ pA}$, o que permitiu a utilização dos monitores de tensão desta fonte para indicação dos valores de tensão da estrutura Van der Pauw, mas o valor de tensão utilizado para o cálculo da resistência de folha foi medido no milivoltímetro por sua maior resolução.

2a. A fonte SMU2 é programada como fonte de corrente com valor nominal de $4.532 \text{ mA} \pm 1 \mu\text{A}$ a fonte SMU3 é programada como fonte de tensão com valor de $0 \text{ V} \pm 1 \text{ mV}$ e seu monitor utilizado para a medida da corrente, e as fontes SMU4 e SMU1 são programadas como fontes de corrente com valores nominais de $10 \text{ pA} \pm 1 \text{ pA}$. Novamente a medida de tensão é feita através do segundo milivoltímetro HP 3478.

O valor de 4.532 mA para a fonte de corrente foi escolhido para medida de resistência de folha do polissilício e da difusão de maneira a obter-se valores de tensão da ordem de dezenas de milivolts. Este valor levou em consideração também a dissipação de potência no polissilício. A figura 2.4.3 mostra um gráfico do valor da resistência de folha em função da corrente. Podemos verificar neste gráfico que a influência do aumento de temperatura interna, devido a dissipação de potência, sob o valor da resistência de folha introduziu um erro sistemático que foi calculado em 1.5% .

Dependência de R_s com a corrente Estrutura Van Der Pauw

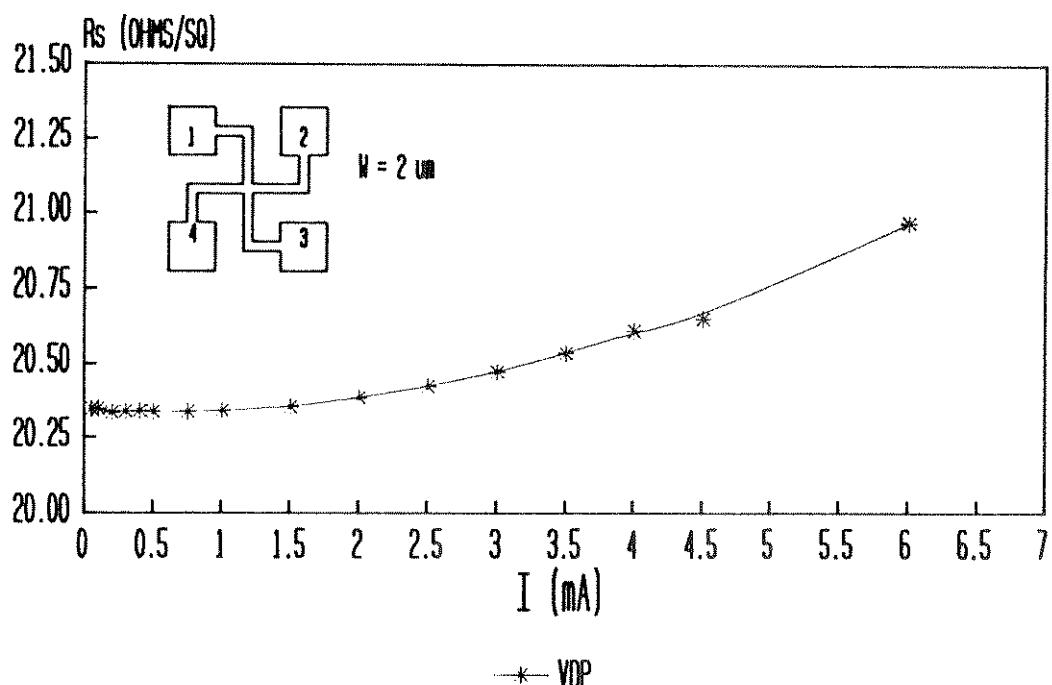


fig.2.4.3

Figura 2.4.3 - Influência da corrente na resistência de folha devido a dissipação de potência no polissilício, observada em estruturas Van Der Pauw com largura de linha de 2 μm .

Entre as etapas de medida de resistência de folha da estrutura proposta foi introduzida uma etapa de aterramento dos pontos de medida, ou seja, nesta etapa todos os SMU's foram programados como fonte de tensão de valor nominal OV. Esta etapa foi introduzida devido a ocorrência de oscilações das medidas, quando da mudança de uma etapa de medida para outra. Estas oscilações foram observadas principalmente na medida da resistência de folha no polissilício o que nos levou a concluir que estas eram devidas a descarga das capacitâncias parasitas formadas entre o nível do polissilício e o silício. Com a introdução das etapas de aterramento as oscilações desapareceram, e a constatação do aparecimento de corrente nas fontes de tensão na etapa de aterramento, confirmou a hipótese feita.

Portanto, para a realização da medida da resistência de folha foram feitos três programas diferentes no HP4145B, para cada uma das etapas de medida e para a etapa de aterramento. Estes programas foram denominados RS1, RS2 e GND. Foi criado um programa de sequencialização dos programas de medidas. A sequência utilizada foi a mesma para a medida da resistência de folha do polissilício, do metal 1 a da difusão, só diferindo nos valores de corrente programados em RS1 e RS2 em cada caso, a saber: RS1-GND-RS2-GND.

A resistência de folha foi medida nas estruturas de polissilício e de metal 1 totalizando 1120 medidas, sendo 800 realizadas no polissilício e 320 no metal 1.

As estruturas de Van Der Pauw convencionais foram medidas para as camadas de polissilício, metal 1 e difusão, totalizando 480 medidas. Os valores obtidos nas estruturas convencionais e proposta estão mostrados no apêndice I.

Com base nos valores obtidos nas medidas realizadas nas estruturas, foram construídos gráficos que mostram a variação da média da resistência de folha no circuito de teste em função da posição do circuito de teste, para as colunas da esquerda e da direita. Os resultados obtidos nas estruturas de Van Der Pauw convencionais são mostrados nos gráficos das figuras 2.4.4 a e b para o polissilício, nas figuras 2.4.5 a e b para o metal 1, e nas figuras 2.4.6 a e b para a difusão. Os resultados para a estrutura de teste proposta estão mostrados nos gráficos das figuras 2.4.7 a e b para o polissilício, e 2.4.8 a e b para o metal 1.

Os valores da função de correção de Van Der Pauw estão mostrados na tabela 2.4.1 abaixo:

Estruturas de Van Der Pauw

material	: R1/R2 médio :	Sigma	:	fator	:	
	: E :	D	: E :	D	: E :	D
Polissilício	:1.083	:1.081	:0.073	:0.061	:.9941	:.9952
Metal 1	:1.32	:1.31	:0.27	:0.27	:.9526	:.9546
difusão	:1.039	:1.042	:0.028	:0.029	:.9988	:.9987

Estruturas propostas

material	: R1/R2 médio :	Sigma	:	fator	:	
	: E :	D	: E :	D	: E :	D
Polissilício	:1.192	:1.182	:0.104	:0.100	:.9858	:.9867
Metal 1	:1.428	:1.413	:0.081	:0.067	:.9777	:.9806

Os valores para o fator de correção foram obtidos aplicando-se os valores de R1/R2 médio mais 3 sigma na curva da figura 1.4.4.3. Nota-se que o máximo erro cometido sobre o valor médio da resistência de folha se desprezarmos o fator de correção é de 5 %. O maior fator de correção nos dois tipos de estrutura foi obtido para o metal 1. Isto é devido ao erro do método de medida que é maior para o metal 1, pois o valor da resistência de folha para o metal 1 é cerca de cem vezes menor do que a do polissilício e da difusão.

Resistência de folha para poli
Van Der Pauw coluna da direita

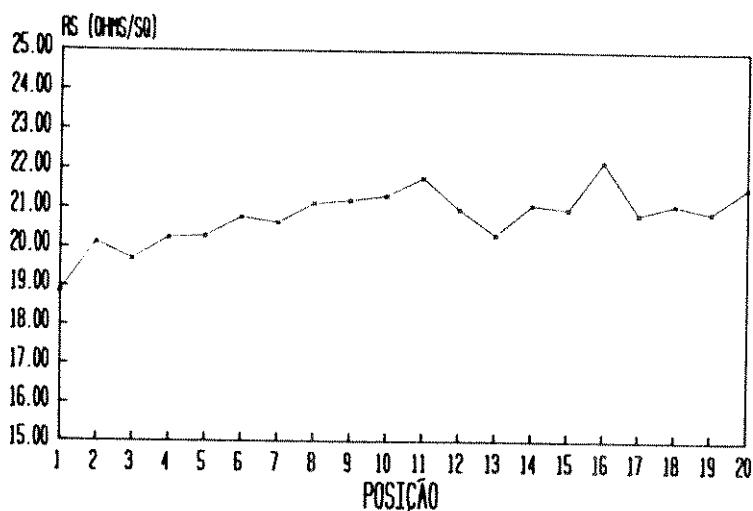


fig. 2.4.4.a

Resistência de folha para o Poli
Van Der Pauw coluna da esquerda

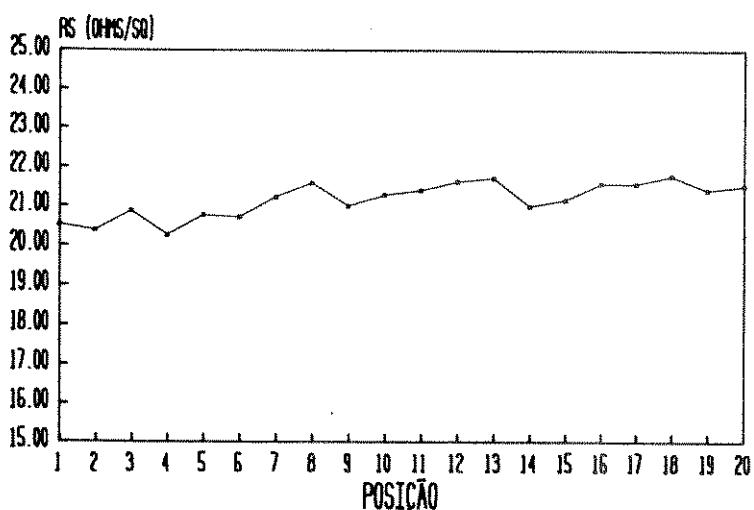


fig. 2.4.4.b

Figura 2.4.4 a e b. Variação da resistência de folha média em um circuito de teste para o polissilício em função da posição da estrutura de Van Der Pauw convencional na lâmina. a) Para a coluna da direita. b) Para a coluna da esquerda.

Resistência de folha para o metal 1
Van Der Pauw coluna da direita

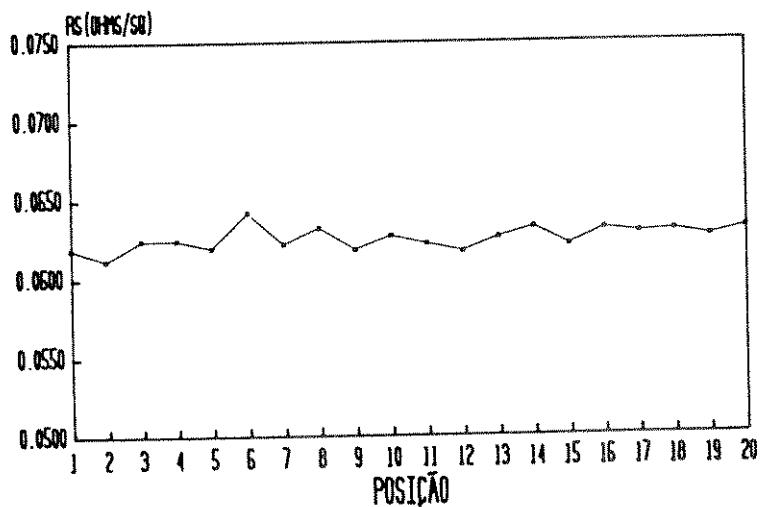


fig. 2.4.5.a

Resistência de folha para o metal 1
Van Der Pauw coluna da esquerda

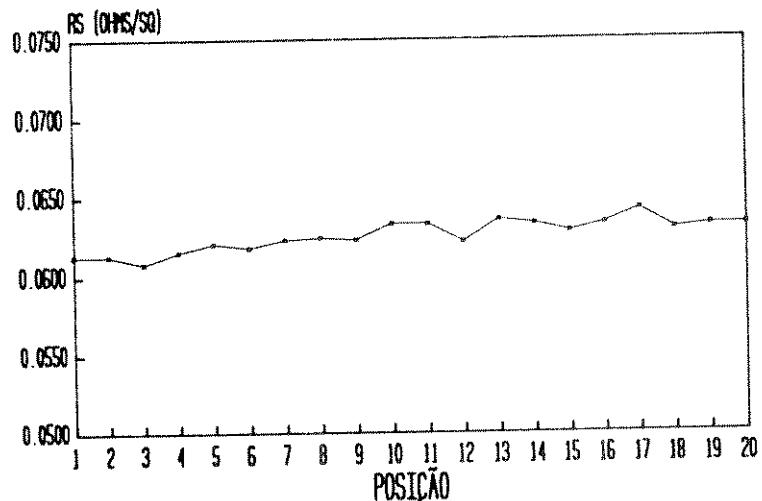
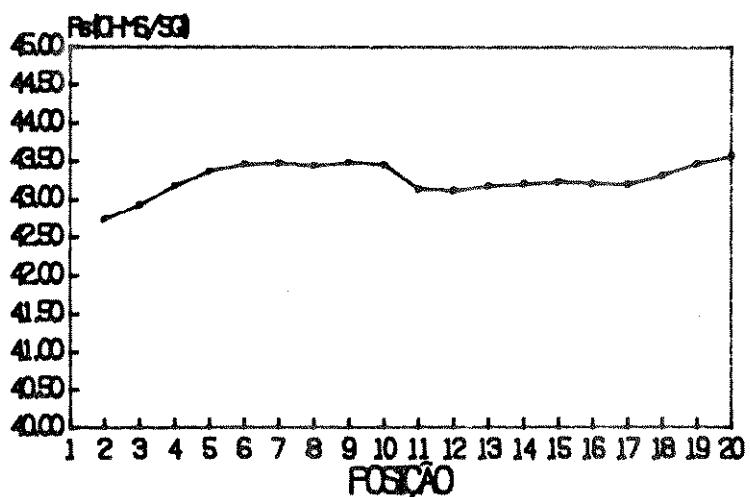


fig. 2.4.5.b

Figura 2.4.5 a e b. Variação da resistência de folha média em um circuito de teste para o metal 1 em função da posição da estrutura de Van Der Pauw convencional na lâmina. a) Para a coluna da direita. b) Para a coluna da esquerda.

Resistência de folha da difusão
Van Der Pauw coluna da direita



Resistência de folha da difusão
Van Der Pauw coluna da esquerda

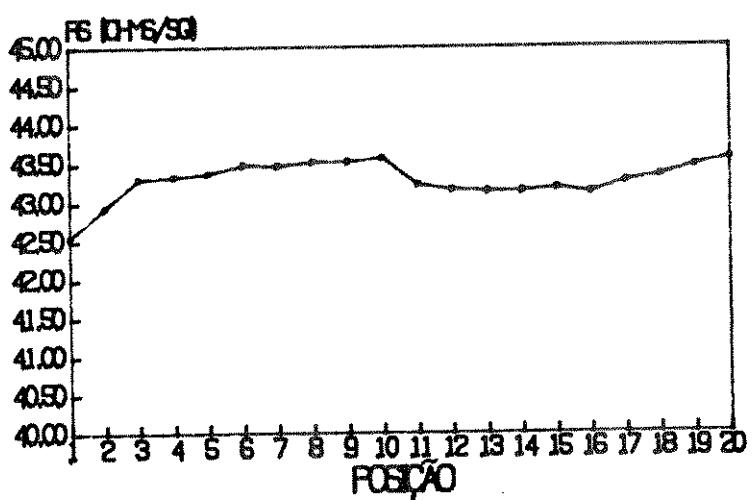
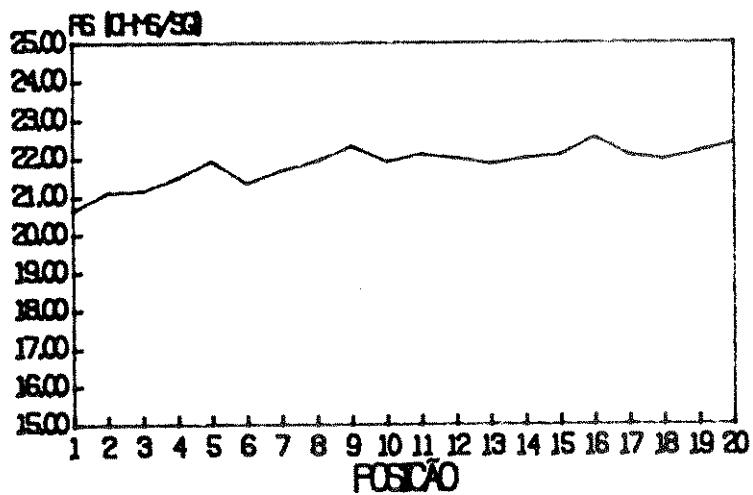


Figura 2.4.6 a e b. Variação da resistência de folha média em um circuito de teste para a difusão em função da posição da estrutura de Van Der Pauw convencional na lâmina. a) Para a coluna da direita. b) Para a coluna da esquerda.

Resistência de folha do poli
estrutura proposta coluna da direita



Resistência de folha do poli
Estrutura proposta coluna da esquerda

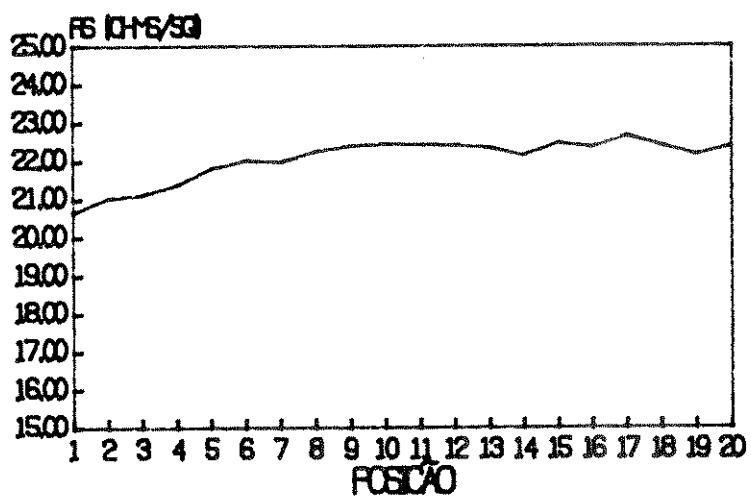


Figura 2.4.7 a e b. Variação da resistência de folha média em um circuito de teste para o polissilício em função da posição da estrutura de teste proposta na lâmina. a) Para a coluna da direita. b) Para a coluna da esquerda.

Resistência de folha para o metal 1
Estrutura proposta coluna da direita

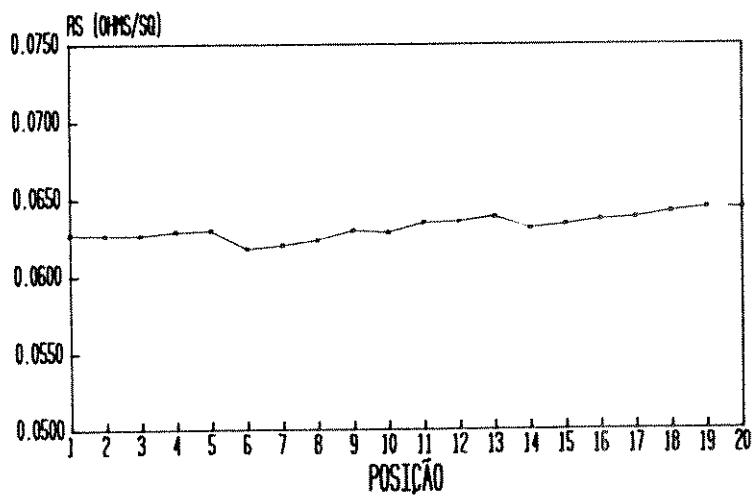


fig. 2.4.8.a

Resistência de folha para o metal 1
Estrutura proposta coluna da esquerda

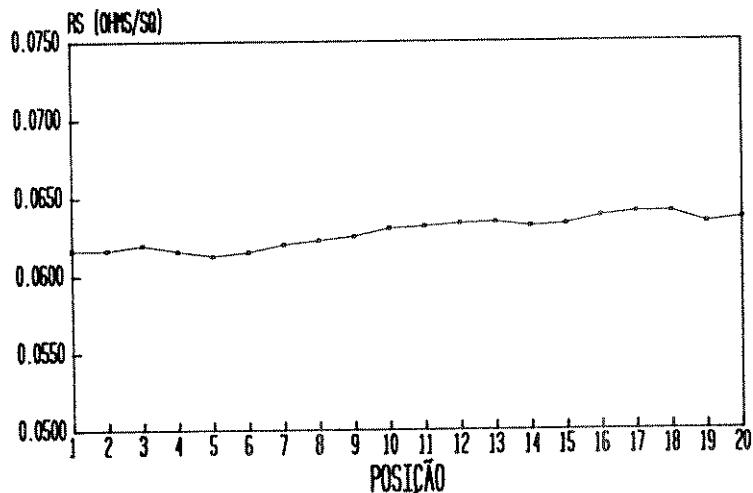


fig. 2.4.8.b

Figura 2.4.8 a e b. Variação da resistência de folha média em um circuito de teste para o metal 1 em função da posição da estrutura de teste proposta na lâmina. a) Para a coluna da direita. b) Para a coluna da esquerda.

Ao compararmos os gráficos da resistência de folha para o polissilício obtidos nas estruturas Van Der Pauw convencional e estrutura proposta, notamos que os valores da estrutura convencional apresentam a mesma variação dos valores da estrutura proposta, mas estes estão deslocados apresentando valores inferiores aos da estrutura proposta. Este fato é explicado pela variação da resistência de folha com a temperatura no polissilício.

Como dito, para a avaliação da resistência de folha nas estruturas Van Der Pauw convencionais, a corrente empregada foi limitada em 4.532 ma devido a dissipação de potência no polissilício. Esta influência da corrente na resistência de folha devido a temperatura esta representado na figura 2.4.3. Este gráfico foi obtido medindo-se a resistência de folha em estruturas Van Der Pauw para vários valores de corrente.

Para a avaliação da resistência de folha nas estruturas propostas o mesmo valor de corrente foi empregado, mas devido a estrutura proposta possuir o comprimento dos braços da cruz que forma a estrutura de Van Der Pauw muito maior do que os braços da estrutura convencional, a resistência destes braços é maior resultando numa maior potência dissipada, e consequentemente numa elevação de temperatura. Portanto, para o mesmo valor de corrente, a elevação da temperatura no polissilício para a estrutura proposta resultou na obtenção de valores maiores para a resistência de folha medida nesta estrutura. Por tratar-se de um erro sistemático, ele não induz na deterioração da precisão do método, podendo ser corrigido uma vez conhecida esta diferença.

Para constatar estas afirmações foi construído um gráfico da resistência de folha nas estruturas propostas em função da corrente. Este gráfico é mostrado na figura 2.4.9, sobreposto ao gráfico da figura 2.4.3. Pode-se verificar desta figura uma variação de 3.8% do valor da resistência de folha na estrutura 1A, e 2% na estrutura 2A.

Dependência de R_s com a corrente
Poli estr. 1A, 2A e Van Der Pauw

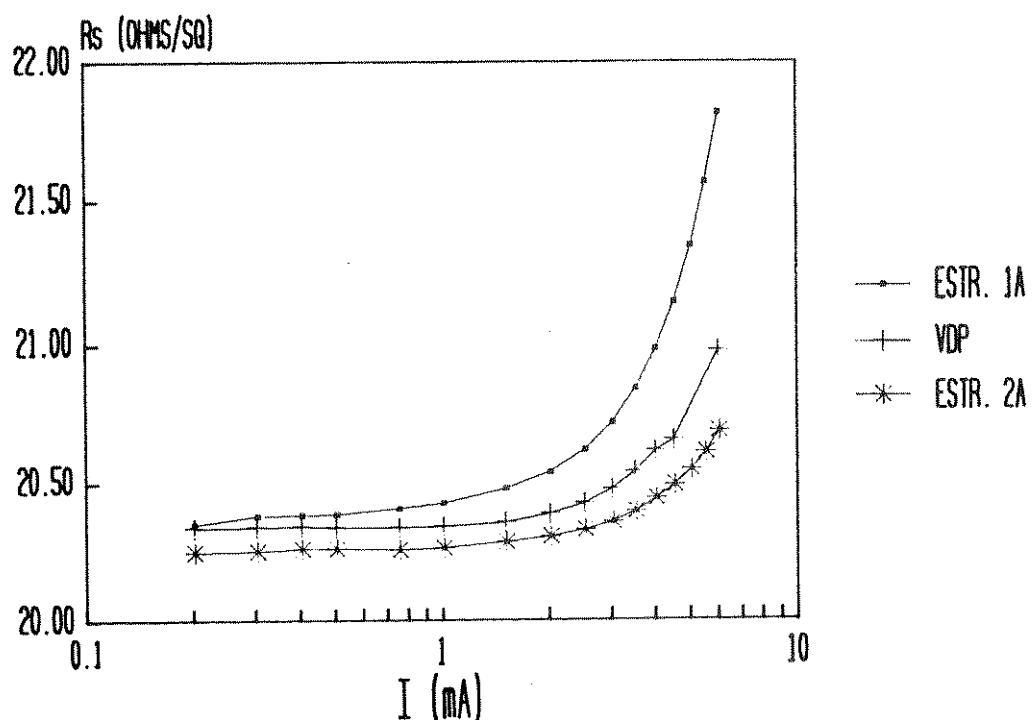


fig.2.4.9

Figura 2.4.9. Gráfico da resistência de folha nas estruturas propostas e na estrutura convencional em função da corrente.

A variação da resistência de folha do polissilício nas estruturas convencional e proposta, indica uma não uniformidade na espessura ou na composição da camada em função da posição da ordem de 15% em 3 sigma. Métodos para a avaliação da natureza destas variações serão objeto de trabalho futuro.

Para os resultados obtidos para o metal 1, a grande variação notada no gráfico da figura 2.4.5 foi devido a resolução da medida de tensão, que corresponde a $\pm 1 \mu\text{V}$ em $60 \mu\text{V}$, ou ainda $\pm 1.7 \%$.

A variação observada corresponde a $\pm 1.6 \%$. O gráfico da figura 2.4.8 que corresponde a mesma medida na estrutura proposta, mostra o mesmo comportamento. Neste gráfico não existe o erro sistemático causado pela temperatura, devido ao baixo valor de resistência do metal.

Da análise da figura 2.4.6 podemos notar uma variação nos valores obtidos para a resistência de folha nos circuitos situados na periferia da lâmina.

2.5 Os procedimentos das medidas de largura de linha e a análise dos resultados obtidos

Para a avaliação da largura de linha foram utilizados os mesmos equipamentos que possibilitaram a avaliação da resistência de folha. O esquema de medida empregado está mostrado na figura 2.5.1., e permite a medida das larguras de linha W_1 e W_2 nos eixos X e Y sem que seja necessária a troca de posição das ponteiras ou dos voltímetros. As fontes de corrente do equipamento HP 4145B foram programadas em duas etapas.

Na primeira etapa o SMU 2 foi programado como fonte de corrente/monitor de tensão com valor nominal I, o SMU 4 foi programado como fonte de tensão/monitor de corrente com valor nominal de 0 volts. Os SMU's 1 e 3 não foram programados não interferindo na medida nesta etapa . Nesta configuração o voltímetro V_1 mede a queda de tensão sobre a linha de largura W_1 , o voltímetro V_2 mede a queda de tensão sobre a largura de linha W_2 e o SMU 4 indica o valor da corrente que circula pelas duas linhas do eixo X.

Na segunda etapa os SMU's 2 e 4 não foram programados, o SMU 1 foi programado como fonte de corrente de valor nominal I e o SMU 3 foi programado como fonte de tensão com valor nominal de 0 volts. Os voltímetros V_1 e V_2 medem as quedas de tensão nas linhas de largura W_1 e W_2 no eixo Y.

Foram avaliadas com este esquema de medida as estruturas para medida de largura de linha construídas em polissilício e as estruturas construídas em metal 1. Para o polissilício o valor de corrente I utilizado foi de 0.1 ma e no metal 1 de 10 ma, devido aos problemas de dissipação, como já explicado.

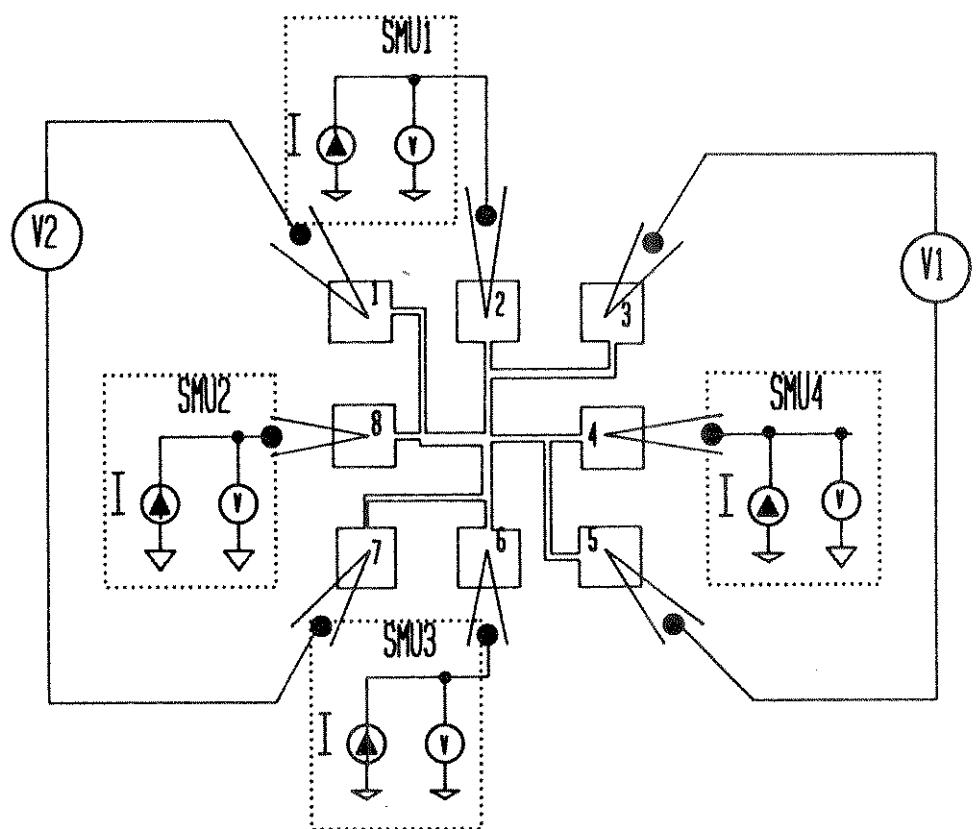


fig. 2.5.1

Figura 2.5.1. Esquema utilizado na medida de largura de linha nas estruturas propostas.

Os programas receberam o nome de LWXA e LWYA para a primeira etapa e LWXB e LWYB para a segunda etapa. Os programas foram sequencializados de maneira idêntica a apresentada na sequencialização das medidas de resistência de folha. O programa de sequencialização para medida da largura de linha no polissilício recebeu o nome de MEDL e o de medida da largura de linha no metal 1 recebeu o nome de MELM.

No polissilício foram medidas as estruturas 1A, 2A, 4A, 5A e 6A. A estrutura 3A que é uma estrutura para medida de largura de linha com efeito de interproximidade, com linhas de 1 μm e 2 μm e com separação de 1 μm , não pode ser medida pois as linhas não foram definidas devido ao efeito de interproximidade que provocou a união da linha com a configuração interna da estrutura. A figura 2.5.2 mostra a estrutura 3A, onde se pode notar a não definição das linhas. Observa-se nesta estrutura que a separação de uma das linhas está definida, enquanto que para o restante das linhas esta separação não ocorreu. Esta separação ocorreu, por ter sido previsto no projeto uma separação de 1.5 μm ao invés de 1 μm para um dos lados da largura de linha W_1 no eixo Y, para a estrutura 3A. Na estrutura 4A, esta separação foi projetada para 2.5 μm , e os efeitos desta separação serão mostrados na análise dos resultados.

No metal 1 foram medidas as estruturas 6C e 7C.

No total foram realizadas 1600 medidas de largura de linha no polissilício e 640 medidas no metal 1.

Devido ao grande número de medidas, foi desenvolvido um programa para interligação dos equipamentos utilizados a um computador PC-XT, via interface de comunicação IEE-488. Este programa possibilitou a aquisição automática dos dados obtidos, gerando arquivos de dados que posteriormente foram tratados de maneira a possibilitar a interpretação dos resultados. Este programa recebeu o nome de IxV e foi também utilizado para a determinação da estabilidade do sistema empregado, através da medida repetitiva em uma mesma estrutura em intervalos de tempo pré-determinados.

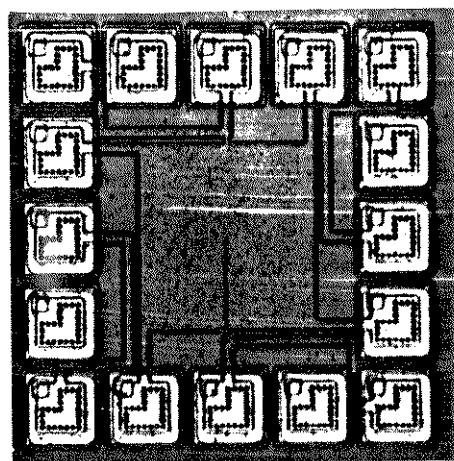


Figura 2.5.2 Estrutura 3A obtida pelo processo de fabricação utilizado, onde verifica-se a não definição das linhas de $1\mu m$ devido ao efeito de interproximidade.

Uma listagem do programa IxV é apresentada no apêndice V.

A partir dos valores medidos foram calculadas as larguras de linha W_1 e W_2 para todas as estruturas medidas. Foram calculados também os valores de delta para os eixos X e Y em todas as estruturas avaliadas. Os resultados obtidos serão apresentados graficamente e analisados visando obter-se informações sobre o equipamento, processo e estratégias de escrita por feixe eletrônico empregadas pela fundição na fabricação de circuitos integrados.

As figuras 2.5.3 até 2.5.9 apresentam os gráficos das médias das larguras de linha por circuito de teste, para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado. As figuras 2.5.10 a 2.5.16 apresentam gráficos semelhantes, para a coluna da esquerda.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 1A coluna da direita

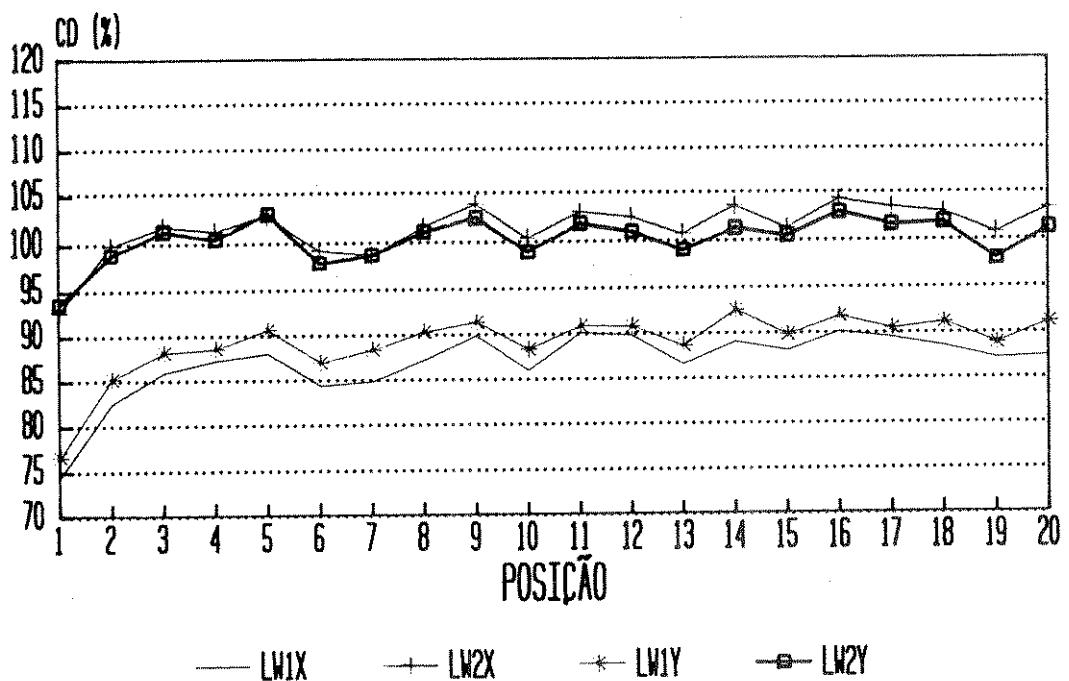


fig 2.5.3

Figura 2.5.3 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 1A, por circuito de teste , para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 2A coluna da direita

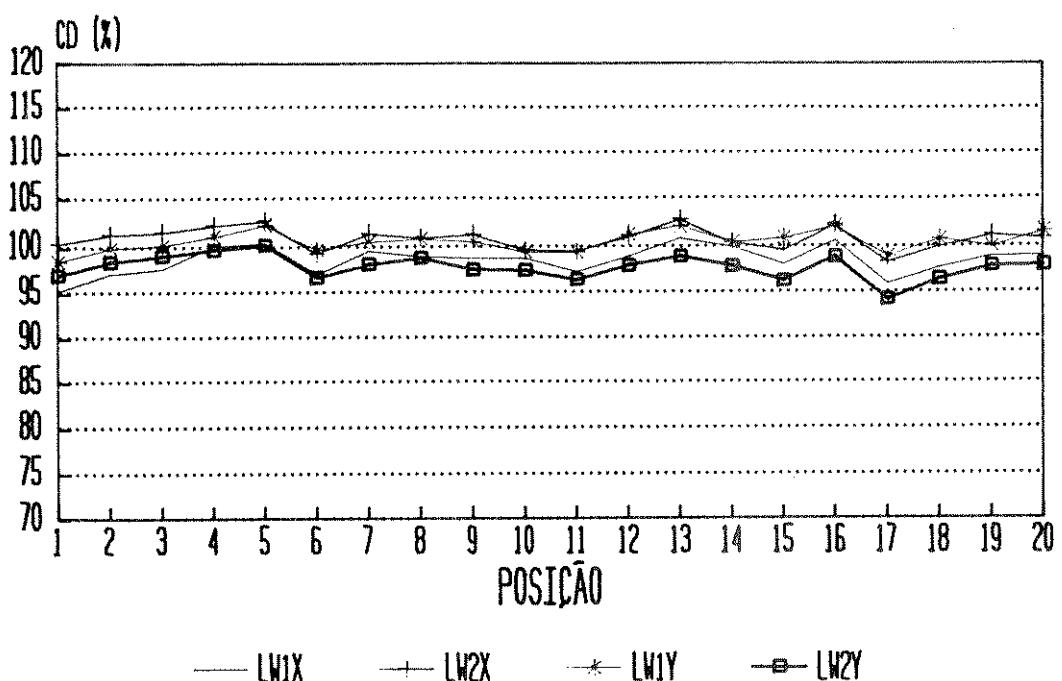


fig 2.5.4

Figura 2.5.4 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 2A, por circuito de teste , para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 4A coluna da direita

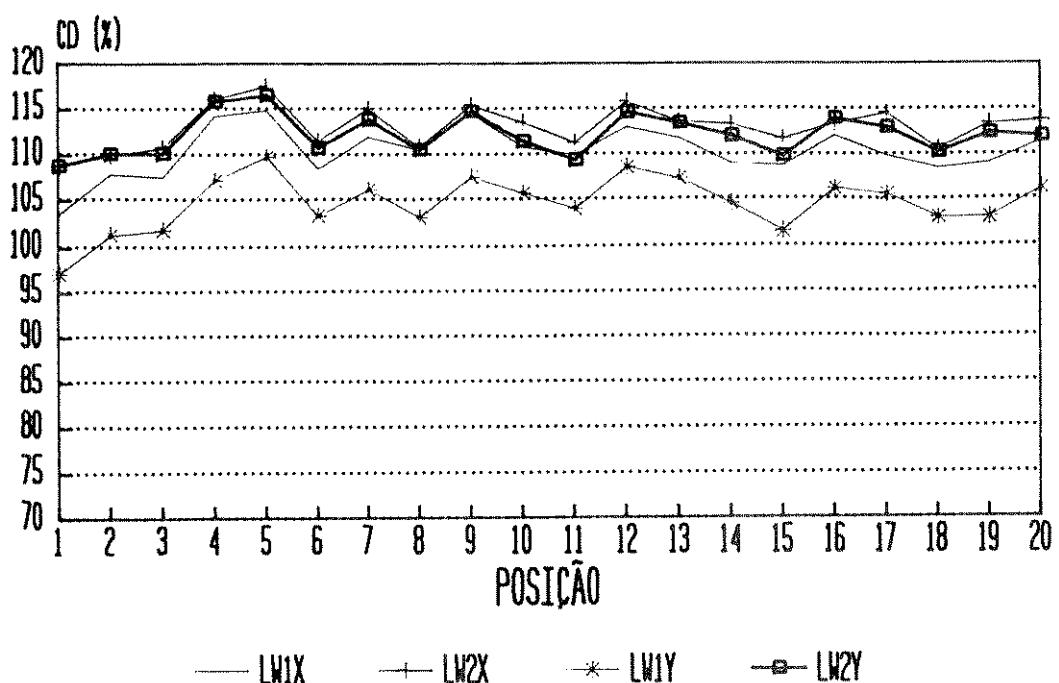


fig 2.5.5

Figura 2.5.5 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 4A, por circuito de teste, para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 5A coluna da direita

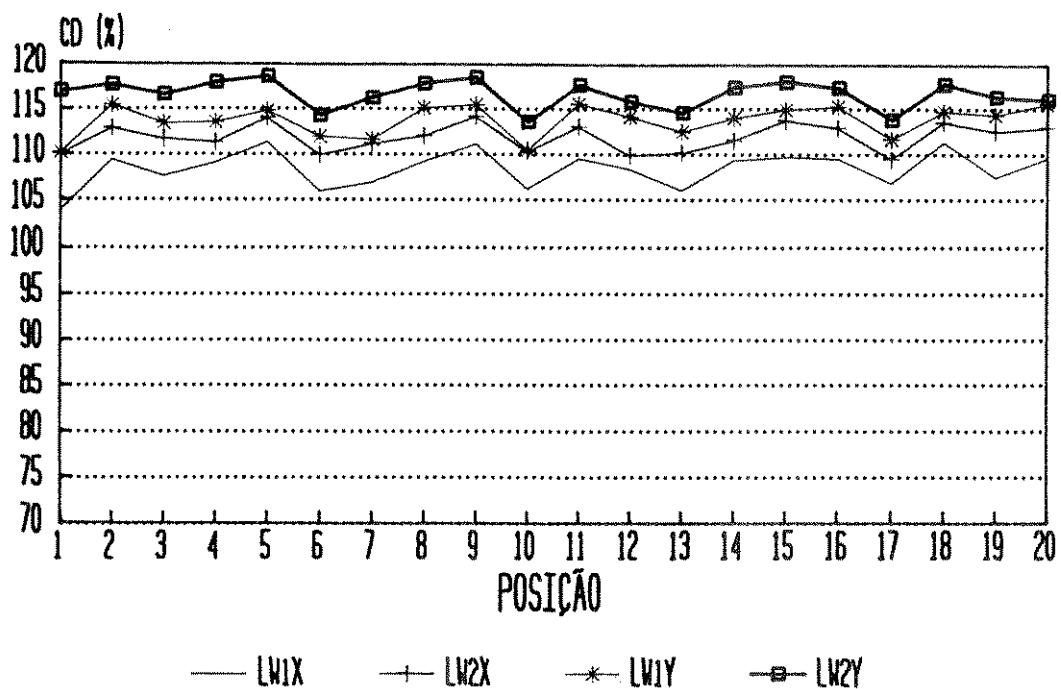


fig 2.5.6

Figura 2.5.6 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 5A, por circuito de teste , para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 6A coluna da direita

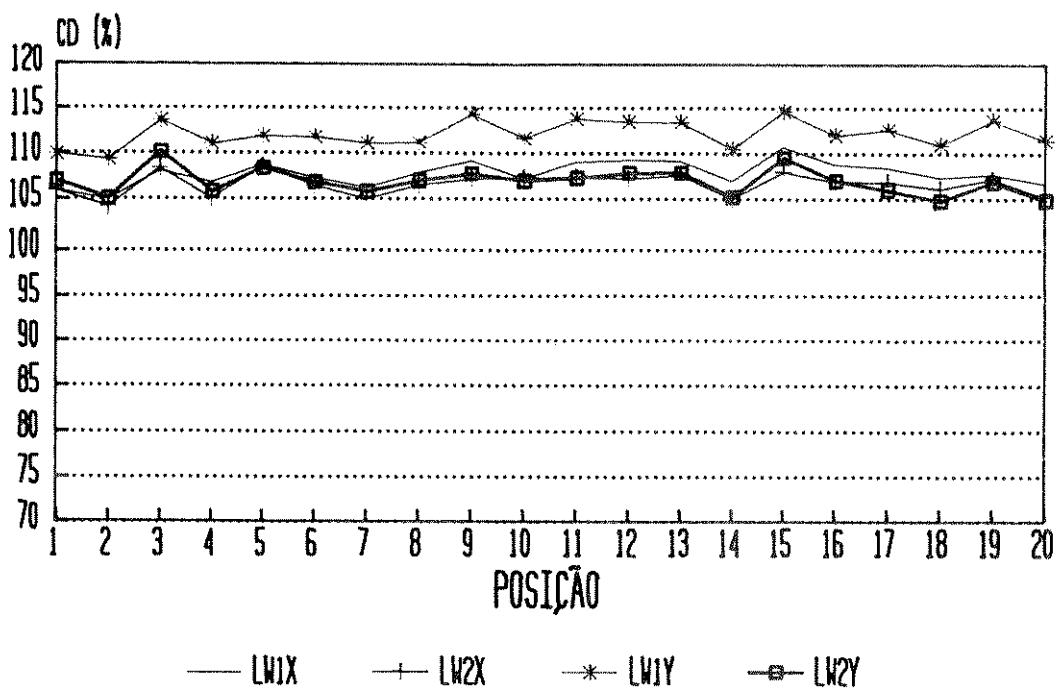


fig 2.5.7

Figura 2.5.7 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 6A, por circuito de teste , para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 6C coluna da direita

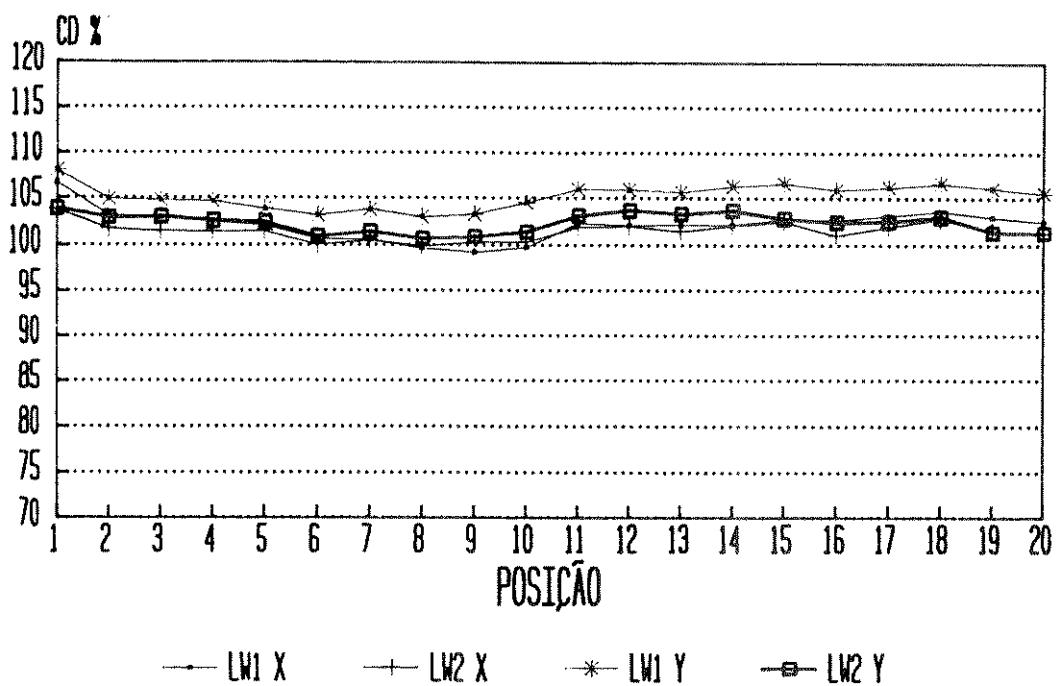


fig 2.5.8

Figura 2.5.8 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 6C, por circuito de teste , para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 7C coluna da direita

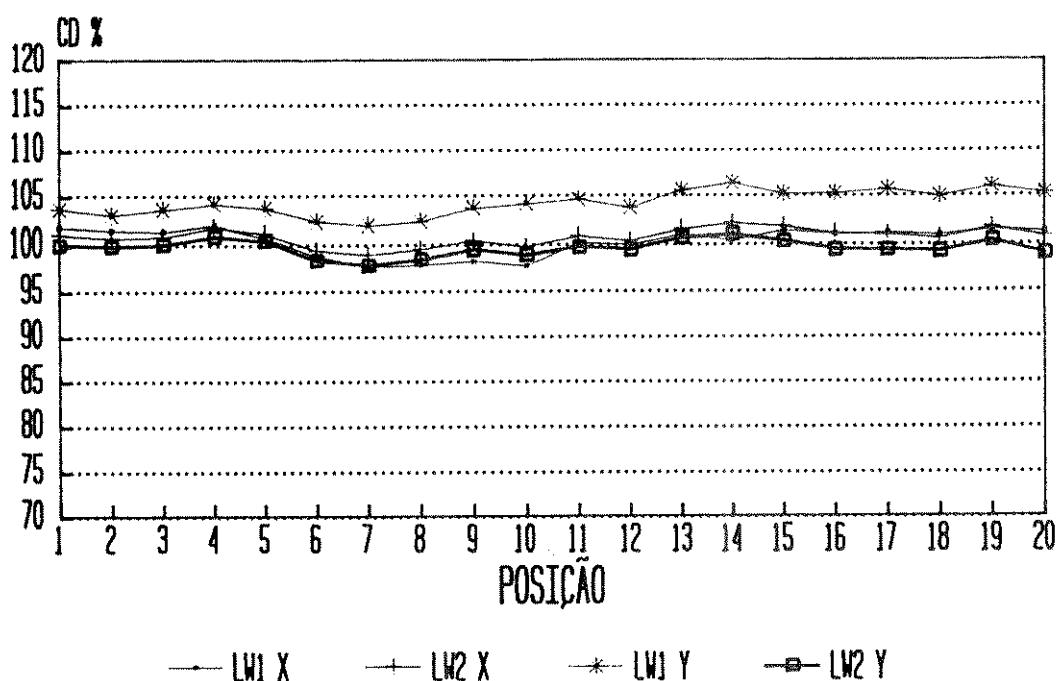


fig 2.5.9

Figura 2.5.9 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 7C, por circuito de teste , para a coluna da direita, calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 1A coluna da esquerda

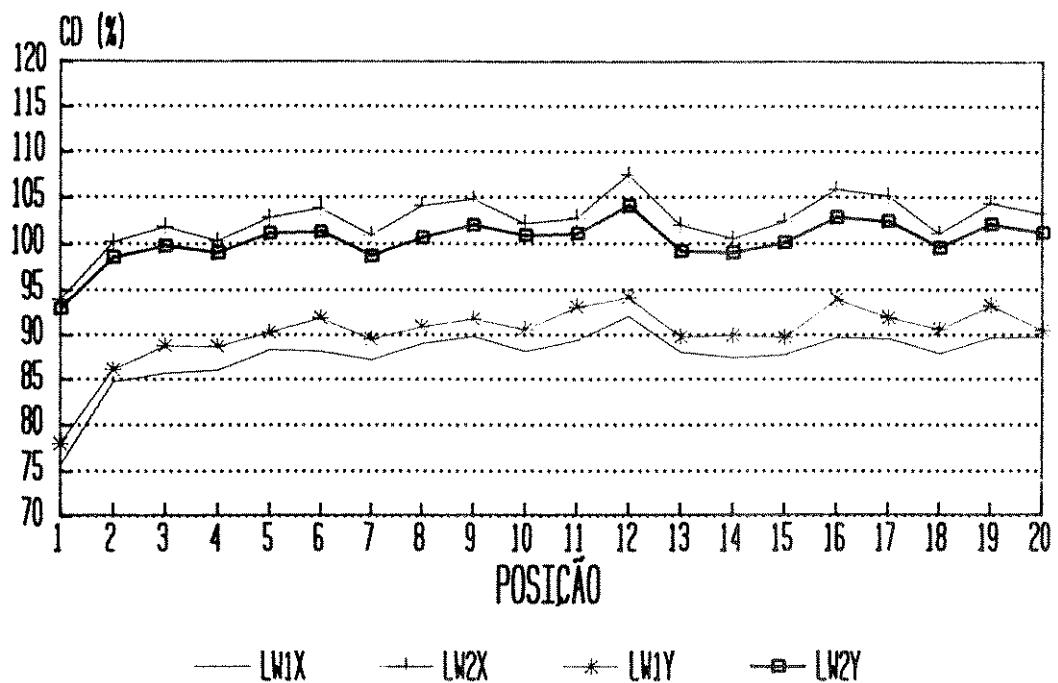


fig 2.5.10

Figura 2.5.10 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 1A, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 2A coluna da esquerda

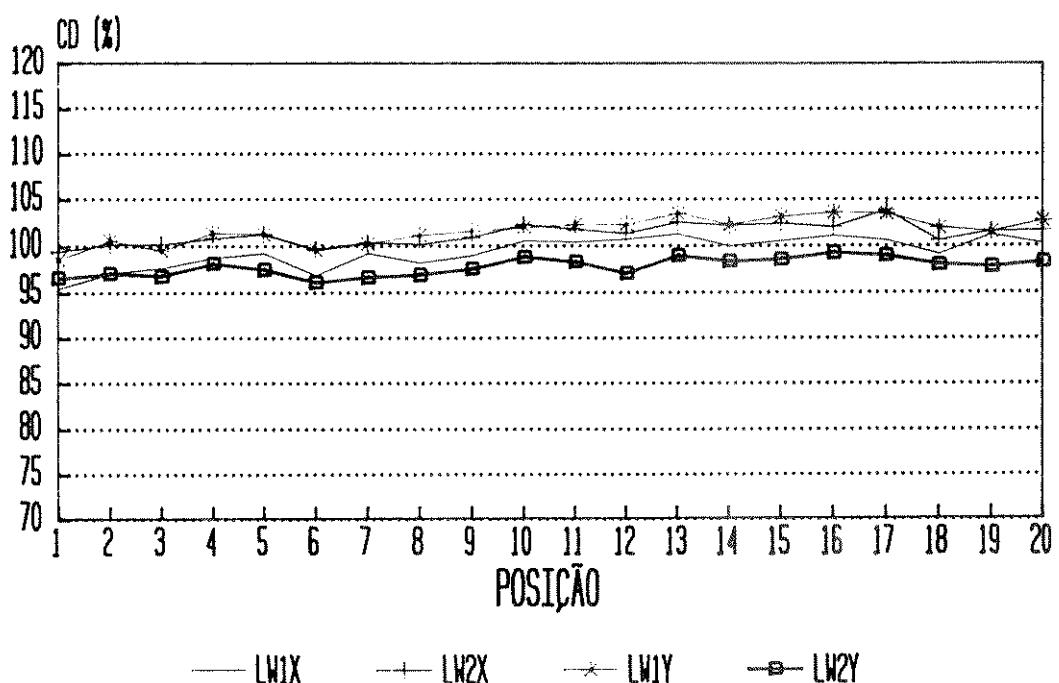


fig 2.5.11

Figura 2.5.11 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 2A, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 4A coluna da esquerda

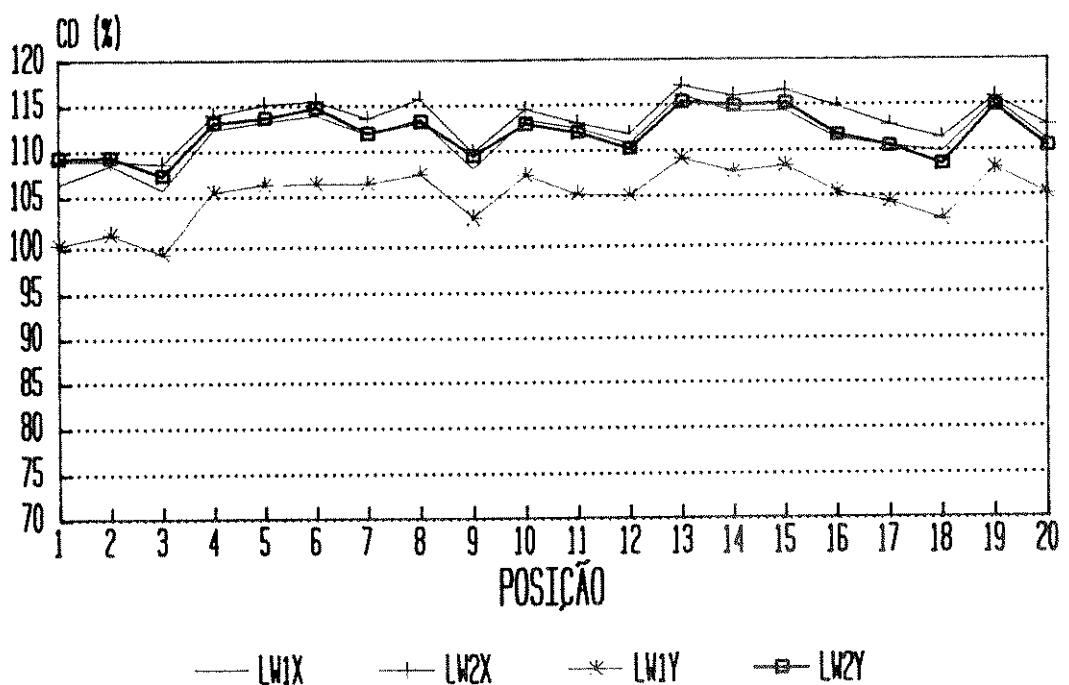


fig 2.5.12

Figura 2.5.12 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 4A, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 5A coluna da esquerda

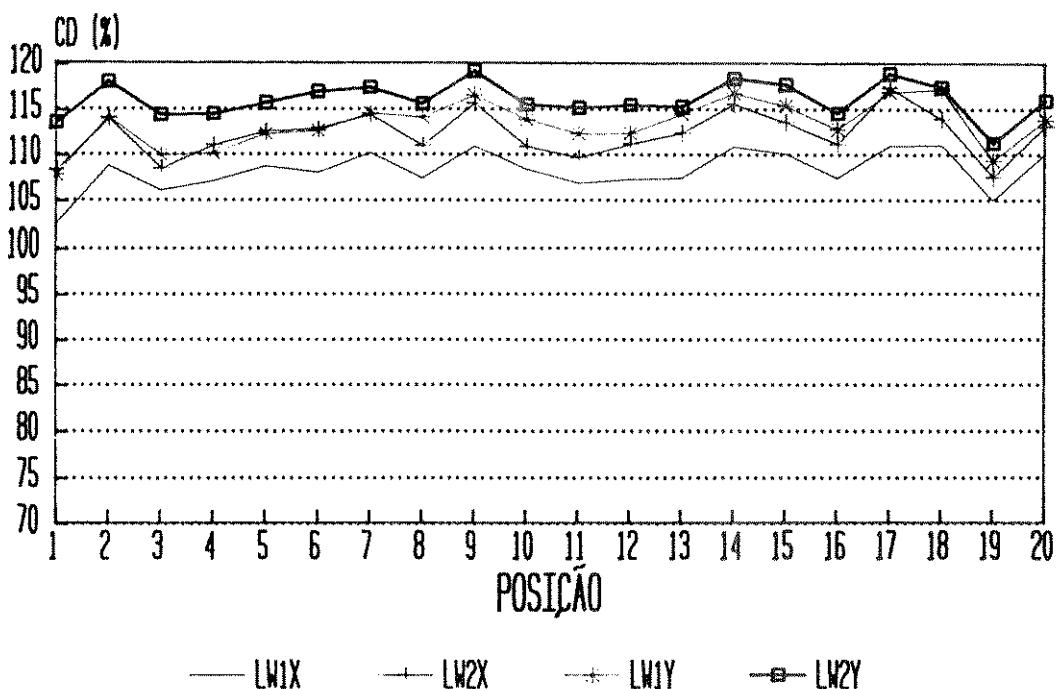


fig 2.5.13

Figura 2.5.13 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 5A, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 6A coluna da esquerda

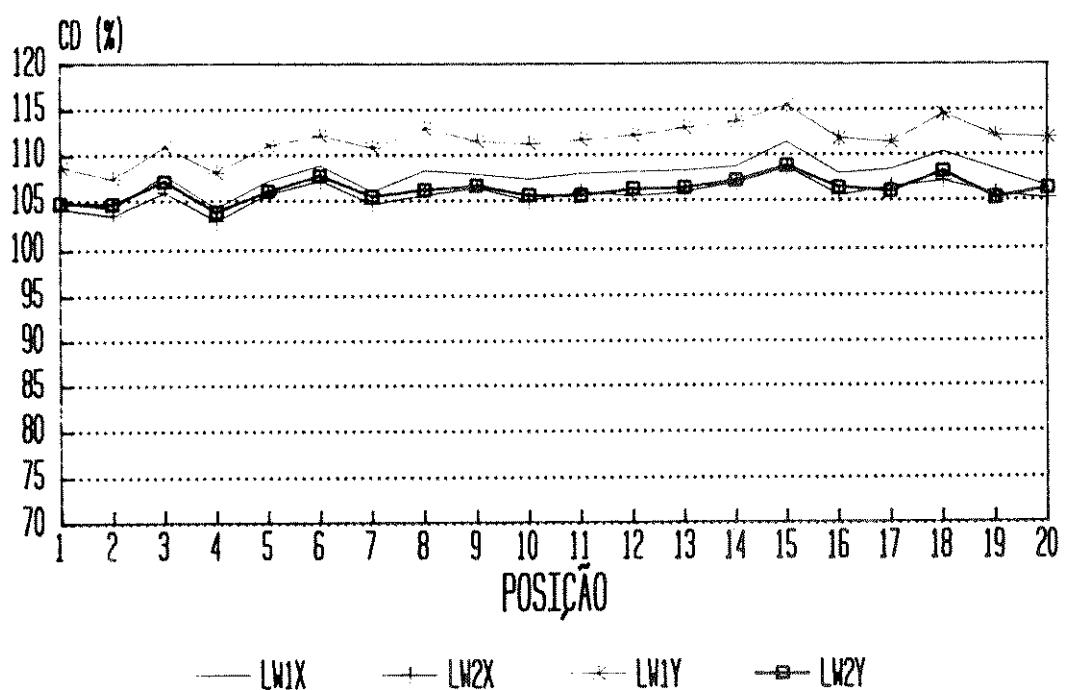


fig 2.5.14

Figura 2.5.14 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 6A, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 6C coluna da esquerda

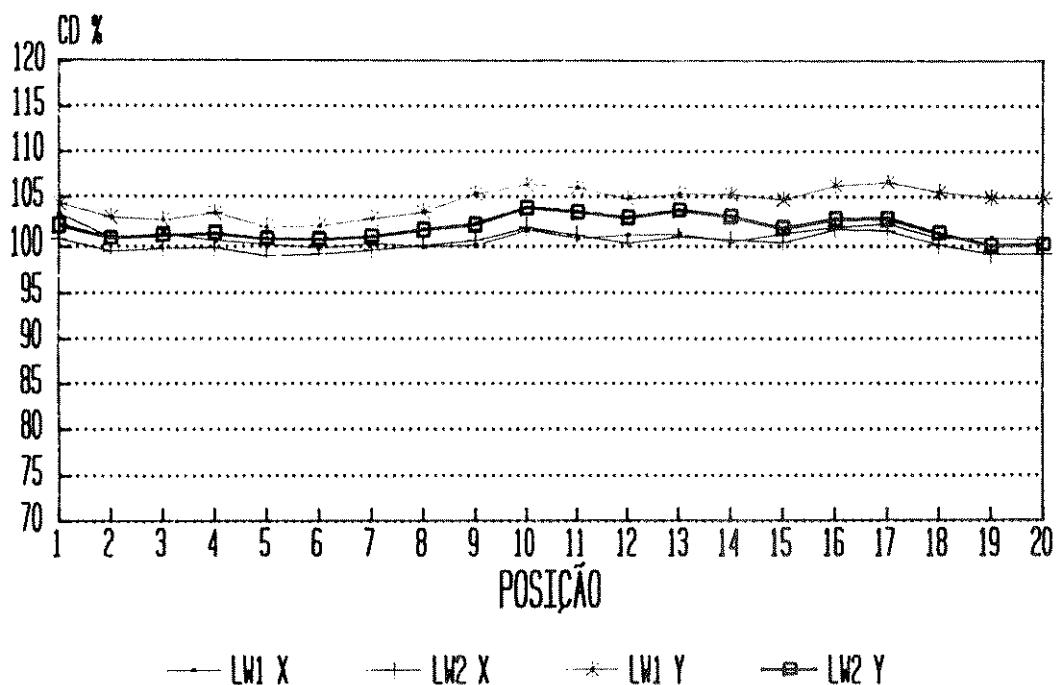


fig 2.5.15

Figura 2.5.15 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 6C, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

Média percentual da largura de linha
Estrutura 7C coluna da esquerda

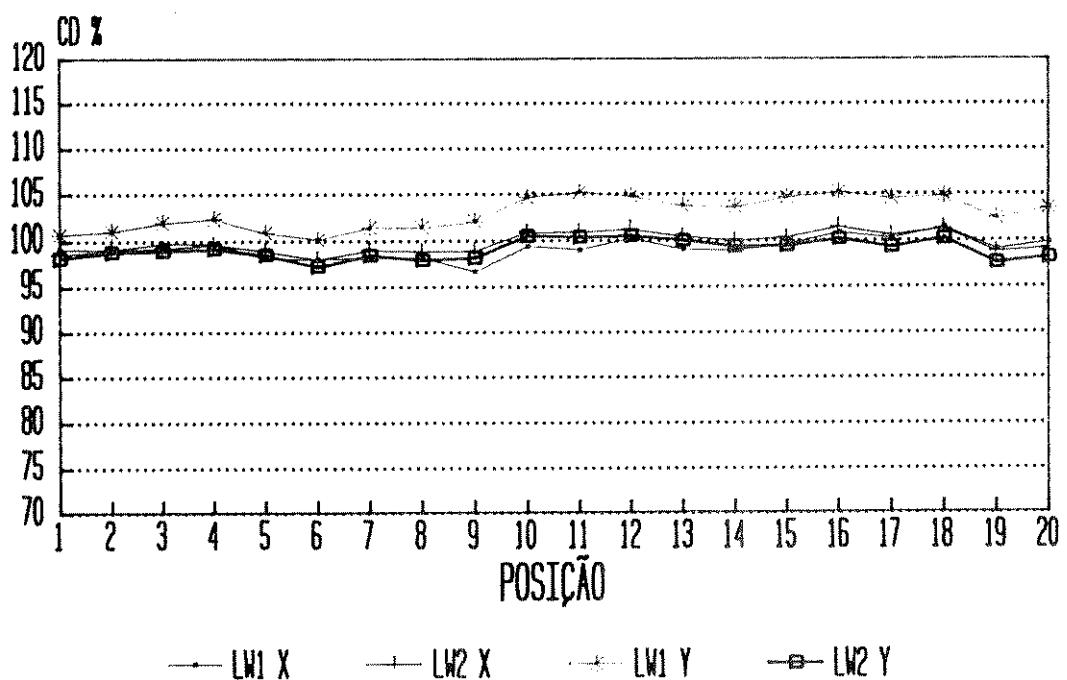


fig 2.5.16

Figura 2.5.16 Apresenta gráfico das médias das larguras de linha na estrutura 7C, por circuito de teste , para a coluna da esquerda calculadas porcentualmente em relação ao valor projetado.

A análise destes gráficos será feita para cada parâmetro litográfico.

2.5.1 Efeito de proximidade.

Como já comentado, as estruturas 1A e 2A foram projetadas de maneira a mostrar o efeito de intraproximidade para dois conjuntos de largura de linha. A finalidade destas estruturas é a verificação da utilização do método de correção de efeito de proximidade e a sua efetividade na correção dos efeitos de intraproximidade.

O gráfico da figura 2.5.3, mostra os valores obtidos para as larguras de linha na estrutura 1A, para coluna da direita, percentualmente em relação aos seus valores nominais. Deste gráfico pode-se notar que o efeito de intraproximidade é bastante evidente para as linhas LW1X e LW1Y de largura de 1 μm apresentando um valor médio de $0.870 \mu\text{m} \pm 0.035 \mu\text{m}$ para as linhas em X, e $0.891 \mu\text{m} \pm 0.033 \mu\text{m}$ em Y, enquanto que para as linhas LW2X e LW2Y de 2 μm de valor nominal, este efeito não se faz sentir, pois a média dos valores obtidos para esta linha é de $2.033 \pm 0.051 \mu\text{m}$ no eixo X, e $2.010 \mu\text{m} \pm 0.044 \mu\text{m}$ para o eixo Y.

O gráfico da figura 2.5.4 apresenta os valores percentuais em relação aos valores nominais das linhas medidas na estrutura 2A, para a coluna da direita. Nesta estrutura nota-se que para as linhas LW1X e LW1Y com largura nominal de 2 μm , o efeito de intraproximidade está presente embora representando uma redução percentual na largura de linha inferior a 10%. Os valores médios obtidos para as linhas de 2 μm nominais para os eixos X e Y respectivamente são: $1.977 \mu\text{m} \pm 0.030 \mu\text{m}$ e $2.015 \mu\text{m} \pm 0.021 \mu\text{m}$. Para as linhas LW2X e LW2Y com valores nominais de 4 μm , os valores obtidos são : $4.045 \mu\text{m} \pm 0.047 \mu\text{m}$ para o eixo X e $3.921 \mu\text{m} \pm 0.054 \mu\text{m}$ para o eixo Y.

Os gráficos das figuras 2.5.10 e 2.5.11 apresentam os mesmos resultados para a coluna da esquerda. Os valores obtidos para a estrutura 1A, coluna da esquerda, para os eixos X e Y são respectivamente: $0.878 \mu\text{m} \pm 0.032 \mu\text{m}$ e $0.903 \mu\text{m} \pm 0.034 \mu\text{m}$ para as linhas com valor nominal de $1 \mu\text{m}$, e $2.053 \mu\text{m} \pm 0.055 \mu\text{m}$ e $2.010 \mu\text{m} \pm 0.045 \mu\text{m}$ para as linhas de valor nominal de $2 \mu\text{m}$. Para a estrutura 2A, coluna da esquerda são: $1.990 \mu\text{m} \pm 0.032 \mu\text{m}$ e $2.036 \mu\text{m} \pm 0.027 \mu\text{m}$ para linhas com $2 \mu\text{m}$ de valor nominal e $4.059 \mu\text{m} \pm 0.043 \mu\text{m}$ e $3.918 \mu\text{m} \pm 0.036 \mu\text{m}$ para as linhas de $4 \mu\text{m}$.

Estes valores demonstram que o fabricante não utiliza software de correção de intraproximidade, ajustando os parâmetros do seu equipamento de escrita e do processo litográfico para obter as linhas de dimensões maiores ou iguais a $2 \mu\text{m}$ dentro das especificações permitidas para o processo. A não utilização de correção do efeito de intraproximidade pode ser um dos fatores que limitam em $2 \mu\text{m}$ a largura de linha mínima produzida pelo processo.

Outra possibilidade é a da utilização de uma estratégia de correção do efeito de proximidade que não é eficiente na correção do efeito de intraproximidade. Esta possibilidade poderá ser confirmada através da análise dos resultados das medidas realizadas nas outras estruturas que exploram o efeito de interproximidade.

As estruturas 4A, 5A, 6A, para o polissilício e 6C e 7C para o metal 1, foram projetadas para induzirem o aparecimento do efeito de interproximidade. A análise dos resultados obtidos nos dará informações sobre as estratégias adotadas no processo de litografia por escrita direta por feixe eletrônico.

As figuras 2.5.5 e 2.5.12 apresentam os valores percentuais em relação aos valores nominais de $1 \mu\text{m}$ e $2 \mu\text{m}$ para as linhas LW1 e LW2, com espaçamento de $2 \mu\text{m}$ entre estas e as configurações que induzem ao aparecimento do efeito de proximidade, para a estrutura 4A, nas colunas da direita e da esquerda. Da análise destas figuras verifica-se a existência do efeito de interproximidade pois as linhas estão maiores do que o valor nominal de projeto.

A diferença apresentada nos resultados obtidos para linha LW1Y de largura 1 μm no eixo Y, quando comparada com as outras linhas desta estrutura, é explicada pelo espaçamento entre a linha e a configuração que, para o eixo Y, foi projetado para ser de 2.5 μm e não 2.0 μm , como já comentado. Este espaçamento maior reduziu o efeito de interproximidade, fazendo com que a linha apresentasse a sua largura mais próxima do valor nominal, mas ainda apresentando o efeito de interproximidade.

Os valores médios globais obtidos para as larguras de linha na estrutura 4A para a coluna da direita e da esquerda são mostradas na tabela 2.5.1.

ESTRUTURA 4A

	coluna da direita		coluna da esquerda	
	média (μm)	sigma (μm)	média (μm)	sigma (μm)
1 μm X :	1.106	0.027	1.118	0.028
1 μm Y :	1.048	0.029	1.054	0.027
2 μm X :	2.264	0.045	2.272	0.052
2 μm Y :	2.245	0.044	2.242	0.048

Tabela 2.5.1

A estrutura 5A, 6A, 6C e 7C têm como estrutura indutora do efeito de proximidade, a configuração que foi projetada para a avaliação da densidade de defeitos. Como característica principal esta estrutura apresenta uma densidade de configurações muito grande de maneira a simular densidades normalmente encontradas em circuitos integrados de alta integração. Portanto, a correção do efeito de interproximidade nestas estruturas é bastante dificultado levando a obtenção de resultados diferentes daqueles apresentados pela estrutura 4A.

Analisaremos os resultados obtidos nas estruturas 5A e 6A separadamente dos obtidos nas estruturas 6C e 7C pois os processos litográficos empregados na definição de linhas de polissilício e de metal não são os mesmos, o que deverá resultar em comportamentos diferentes com relação ao efeito de proximidade.

Como já mencionado, o range de Bethe, que corresponde ao alcance médio dos elétrons retroespalhados, é uma função dos materiais envolvidos na trajetória dos elétrons. O processo litográfico para a obtenção de linhas no polissilício, consiste na sensibilização de uma camada de eletrorresiste que foi depositada sobre uma camada de óxido que por sua vez foi crescida ou depositada sobre o polissilício. O processo de litografia de linhas em metal consiste basicamente na sensibilização de uma camada de eletrorresiste que foi depositada diretamente sobre o metal. Portanto, no polissilício o elétron atravessa em sua trajetória um sistema ternário composto pelo resisto, pelo óxido e pelo próprio polissilício. No metal, na sua trajetória, o elétron incidente encontra um sistema binário composto do resisto e do metal. O range de Bethe em cada caso será diferente se forem utilizados os mesmos parâmetros litográficos para a definição das linhas de polissilício e de metal 1.

A comparação dos resultados das estruturas 5A e 6A definidas no polissilício com as estruturas correspondentes 6C e 7C definidas no metal 1, nos informará da adoção de diferentes estratégias litográficas para o polissilício e para o metal 1.

As estruturas 5A, figuras 2.5.6 e 2.5.13, e 6A, figuras 2.5.7 e 2.5.14 apresentaram o efeito de interproximidade, como o esperado, para ambas as larguras de linha projetadas, nas direções X e Y. Os valores obtidos para estas estruturas estão mostrados nas tabelas 2.5.2 e 2.5.3

ESTRUTURA 5A

	coluna da direita		coluna da esquerda	
	média (μm)	:	sigma (μm)	:
1 μm X :	1.087	:	0.020	:
1 μm Y :	1.140	:	0.017	:
2 μm X :	2.242	:	0.030	:
2 μm Y :	2.337	:	0.030	:
			2.324	:
			0.038	:

Tabela 2.5.2

ESTRUTURA 6A

	coluna da direita		coluna da esquerda	
	média (μm)	sigma (μm)	média (μm)	sigma (μm)
2 μm X :	2.161	0.027	2.156	0.035
2 μm Y :	2.246	0.030	2.235	0.039
4 μm X :	4.270	0.047	4.236	0.051
4 μm Y :	4.282	0.051	4.254	0.047

Tabela 2.5.3

Da análise dos gráficos das figuras 2.5.6, 2.5.7, 2.5.13 e 2.5.14 e das tabelas 2.5.2 e 2.5.3, conclui-se que o efeito de proximidade está presente até para as linhas de largura nominal de projeto de 4 μm o que nos leva a concluir que o fabricante não adota nenhuma estratégia para correção do efeito de interproximidade.

ESTRUTURA 6C

	coluna da direita		coluna da esquerda	
	média (μm)	sigma (μm)	média (μm)	sigma (μm)
2 μm X :	2.048	0.032	2.023	0.016
2 μm Y :	2.107	0.026	2.090	0.028
4 μm X :	4.064	0.037	4.018	0.036
4 μm Y :	4.102	0.038	4.079	0.044

Tabela 2.5.4

ESTRUTURA 7C

	coluna da direita		coluna da esquerda	
	média (μm)	sigma (μm)	média (μm)	sigma (μm)
2 μm X :	2.011	0.028	1.987	0.021
2 μm Y :	2.088	0.025	2.060	0.032
4 μm X :	4.037	0.034	3.996	0.041
4 μm Y :	3.994	0.034	3.964	0.039

Tabela 2.5.5

Através da análise dos gráficos 2.5.8,9,15 e 16 e das tabelas 2.5.5 e 2.5.6, podemos verificar que o efeito de interproximidade nas estruturas construídas em metal 1 foi minimizado, estando dentro dos limites de $\pm 5\%$ do valor nominal de projeto das larguras de linha. Quando comparamos estes resultados com os obtidos para as estruturas 5A e 6A, verificamos que o efeito de proximidade foi reduzido nas estruturas de metal 1, devido a um possível ajuste dos processos litográfico e de ataque do metal de maneira a compensar este efeito. A otimização do processo litográfico no metal 1, leva a um fraco desempenho do processo quanto ao efeito de proximidade no nível do polissilício, causado pela diferente composição do substrato e do número diferente de camadas a serem atravessadas pelos elétrons incidentes.

A não influência das estruturas periódicas gravadas no polissilício sobre a largura de linha pode ser verificada da comparação dos resultados obtidos para as estruturas 6C e 7C. As estruturas periódicas provocam uma variação na topografia do dispositivo que podem afetar o valor da largura de linha pela desfocalização do feixe, relacionada com a profundidade de foco do sistema eletroóptico do equipamento de litografia, e também pela variação na espessura do resisto empregado. O fato de não ter se notado a influência da variação na topografia sobre a largura de linha, pode significar que para as dimensões estabelecidas na regra de projeto a variação de topografia não é significante, ou seja as variações topográficas são menores que a profundidade de campo de foco do sistema eletroóptico e que a variação introduzida na espessura do resisto está dentro dos limites de controle do processo de deposição de resisto.

Existe também a possibilidade da utilização de técnicas de planarização do substrato de maneira a diminuir as variações da topografia.

2.5.2 Aberrações do sistema eletroóptico

Da observação das figuras apresentadas, vemos que existe uma diferença nos valores obtidos para as larguras de linha medidas no eixo X e no eixo Y. Esta diferença é explicada pela aberração do sistema eletroóptico conhecida como astigmatismo. O astigmatismo é uma distorção no feixe eletrônico causada pela assimetria das lentes eletromagnéticas responsáveis pela focalização do feixe. Esta distorção faz com que o feixe apresente seção elíptica, quando deveria ter seção circular, o que causa uma dependência nas larguras de linha com a direção em que a linha é escrita.

O astigmatismo do feixe é dependente da posição do feixe em relação ao centro do sistema eletroóptico. Quanto mais afastado do eixo do sistema, maior a distorção causada pelas imperfeições das lentes. Portanto o astigmatismo, e por conseguinte as larguras das linhas, são dependentes da varredura do feixe. Esta varredura é definida pelo tamanho de campo utilizado que é dependente da estratégia de escrita.

Analizando-se o comportamento das larguras de linha escritas nas direções X e Y, em função da posição da estrutura de teste dentro da lâmina, podemos deduzir o tamanho de campo utilizado pelo fabricante, bem como inferir sobre as características do equipamento de litografia por feixe eletrônico utilizado na fabricação destes dispositivos.

A seguir apresentamos a tabela 2.5.6 que resume os valores médios e os desvios normalizados em relação aos valores nominais projetados, encontrados para as larguras de linha nas direções X e Y, por estrutura de teste, para as colunas da direita e da esquerda.

	Coluna da esquerda	Coluna da direita
	LW1X : LW1Y : LW2X : LW2Y : LW1X : LW1Y : LW2X : LW2Y :	
1A	10.878 : 10.903 : 11.026 : 11.005 : 10.870 : 10.891 : 11.017 : 11.005 :	
	10.032 : 10.034 : 10.027 : 10.023 : 10.035 : 10.033 : 10.026 : 10.022 :	
2A	10.995 : 11.018 : 11.015 : 10.979 : 10.989 : 11.007 : 11.011 : 10.980 :	
	10.016 : 10.013 : 10.011 : 10.009 : 10.015 : 10.011 : 10.012 : 10.016 :	
4A	11.118 : 11.054 : 11.136 : 11.121 : 11.106 : 11.048 : 11.132 : 11.122 :	
	10.028 : 10.027 : 10.026 : 10.024 : 10.027 : 10.029 : 10.023 : 10.022 :	
5A	11.085 : 11.136 : 11.124 : 11.162 : 11.087 : 11.140 : 11.121 : 11.168 :	
	10.022 : 10.026 : 10.026 : 10.019 : 10.020 : 10.017 : 10.015 : 10.015 :	
6A	11.078 : 11.117 : 11.059 : 11.063 : 11.080 : 11.123 : 11.067 : 11.070 :	
	10.018 : 10.020 : 10.013 : 10.012 : 10.014 : 10.015 : 10.012 : 10.014 :	
6C	11.011 : 11.045 : 11.004 : 11.020 : 11.024 : 11.053 : 11.016 : 11.025 :	
	10.016 : 10.013 : 10.009 : 10.010 : 10.008 : 10.014 : 10.009 : 10.011 :	
7C	10.993 : 11.030 : 10.999 : 10.991 : 11.005 : 11.044 : 11.009 : 10.998 :	
	10.014 : 10.013 : 10.009 : 10.009 : 10.011 : 10.016 : 10.010 : 10.010 :	

Tabela 2.5.6

A tabela 2.5.6 permite verificar que o efeito de proximidade embutido em cada resultado mascara o efeito das distorções nas largura de linha. Como o efeito de proximidade independe da direção em que é escrita a linha, podemos eliminá-lo pela subtração dos valores obtidos para as larguras de linha orientadas segundo o eixo Y dos valores do eixo X. Valores positivos indicam que o astigmatismo do feixe é maior no eixo Y ou seja, o feixe possui o diâmetro em X maior que o diâmetro em Y.

Da análise da tabela 2.5.6, podemos verificar que existem três classes distintas de comportamento.

A primeira corresponde aos resultados apresentados pela estrutura 4A. Para esta estrutura os resultados indicam a existência de astigmatismo do feixe no eixo X. Este resultado está mascarado pela existência do efeito de proximidade diferenciado nesta estrutura, devido a separação diferenciada para as linhas de 1 μm em X e em Y.

A segunda classe de comportamento, corresponde ao apresentado pelas estruturas 5A, 6A, 6C e 7C . Nestas estruturas, os resultados obtidos indicam que para LW1 e LW2, o feixe de elétrons é astigmático apresentando o seu diâmetro em X maior que o diâmetro em Y. Os resultados obtidos para LW2 para as estruturas 6A, 6C e 7C, apresentam valores muito pequenos indicando que para linhas com largura de 4 μm o efeito do astigmatismo do feixe é desprezível. O resultado da estrutura 5A mostra o astigmatismo do feixe para linhas de 1 μm não é desprezível.

A terceira classe corresponde ao comportamento apresentado pelas estruturas 1A e 2A. Os valores apresentados mostram que para as linhas de 1 μm o astigmatismo é maior no eixo Y. Já para as linhas de 2 μm os resultados apontam por um astigmatismo no eixo X. Este tipo de comportamento não é esperado pois o eixo de assimetria do feixe só depende do sistema eletroóptico. Apesar deste comportamento ser contrário ao esperado, ele é pouco significativo pois os desvios são da mesma ordem de grandeza das diferenças dos valores em X e Y.

2.5.3 Desvios da largura de linha induzidos pelo processo

O processo litográfico em suas varias etapas, introduz desvios nos valores projetados para as dimensões presentes no circuito integrado. Estes desvios podem acontecer em diversas etapas do processo e resultam em um "offset", que pode ser positivo ou negativo representando um aumento ou diminuição na dimensão nominal. Com a utilização do processo este "offset" se desloca, aumentando ou diminuindo o seu valor. Existe portanto a necessidade de se monitorar este "offset" mantendo-o sobre controle. Uma vez conhecido e controlado o "offset", pode-se alterar os valores projetados para as dimensões de maneira a compensá-lo.

As estruturas propostas para medida de largura de linha foram projetadas de maneira a possibilitar a avaliação dos desvios do processo. A variação ΔW induzida pelo processo obtida da equação (2.3.8) esta representada nas figuras de 2.5.18 a 2.5.31 para as estruturas propostas e para as colunas da direita e da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 1A coluna da direita

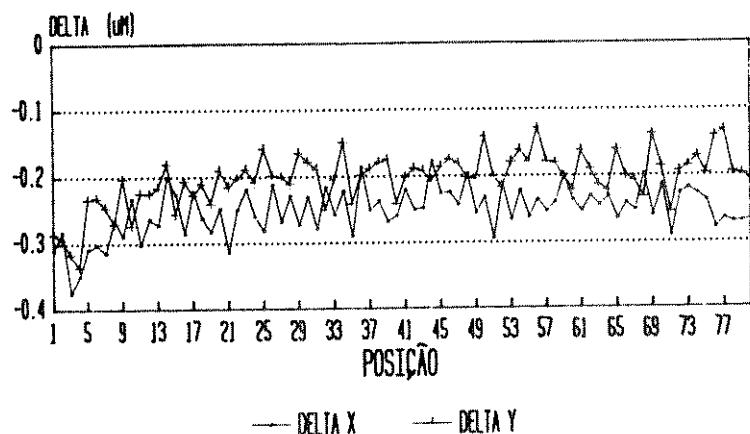


fig 2.5.18

Figura 2.5.18. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 1A coluna da direita .

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 2A coluna da direita

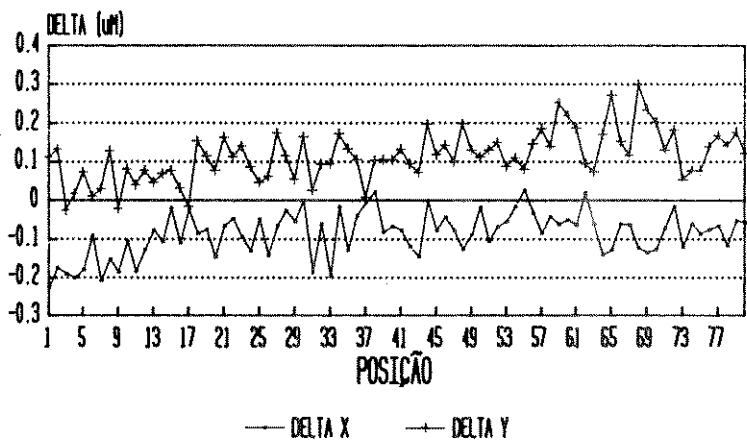


fig 2.5.19

Figura 2.5.19. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 2A coluna da direita.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 4A coluna da direita

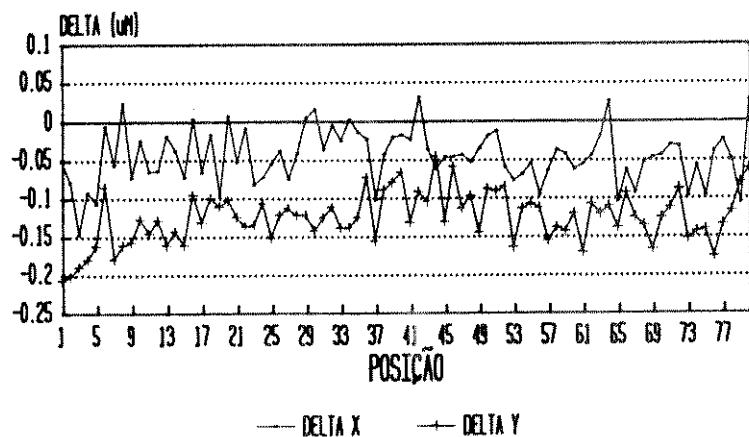


fig 2.5.20

Figura 2.5.20. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 4A coluna da direita.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 5A coluna da direita

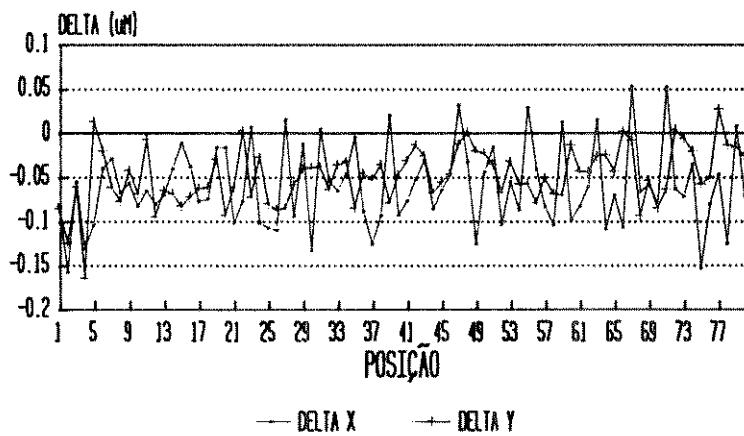


fig 2.5.21

Figura 2.5.21. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 5A coluna da direita.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 6A coluna da direita

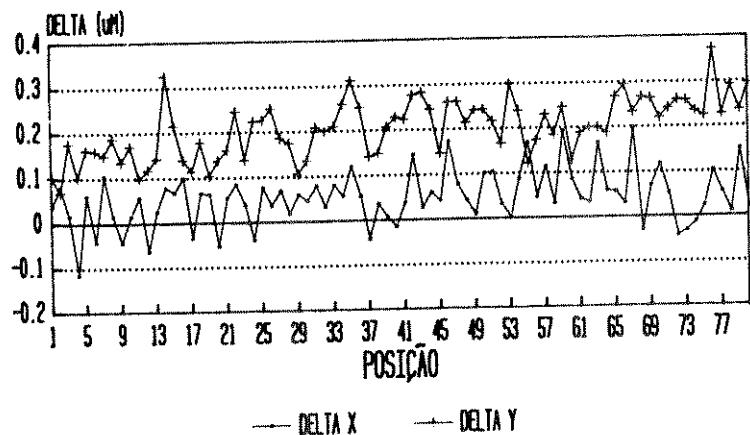


fig 2.5.22

Figura 2.5.22. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 6A coluna da direita.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 1A coluna da esquerda

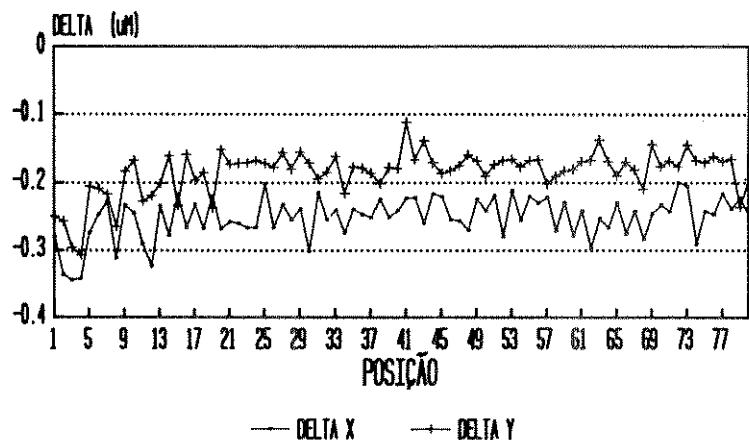


fig 2.5.23

Figura 2.5.23. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 1A coluna da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 2A coluna da esquerda

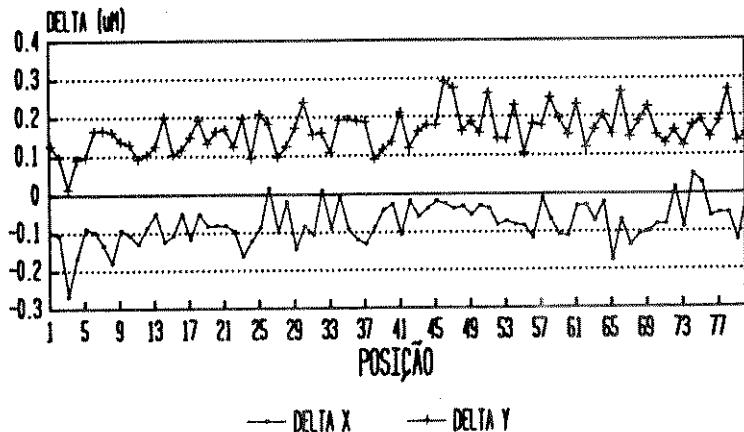


fig 2.5.24

Figura 2.5.24. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 2A coluna da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 4A coluna da esquerda

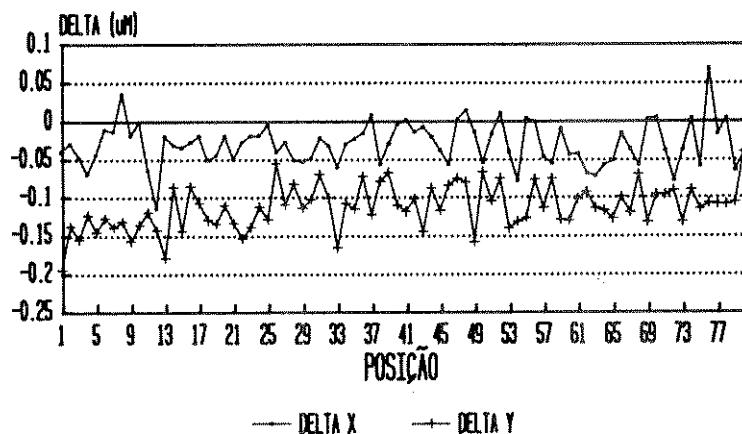


fig 2.5.25

Figura 2.5.25. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 4A coluna da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 5A coluna da esquerda

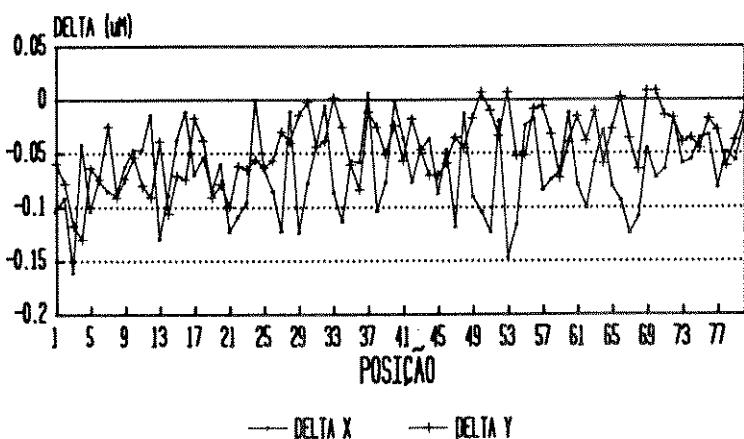


fig 2.5.26

Figura 2.5.26. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 5A coluna da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 6A coluna da esquerda

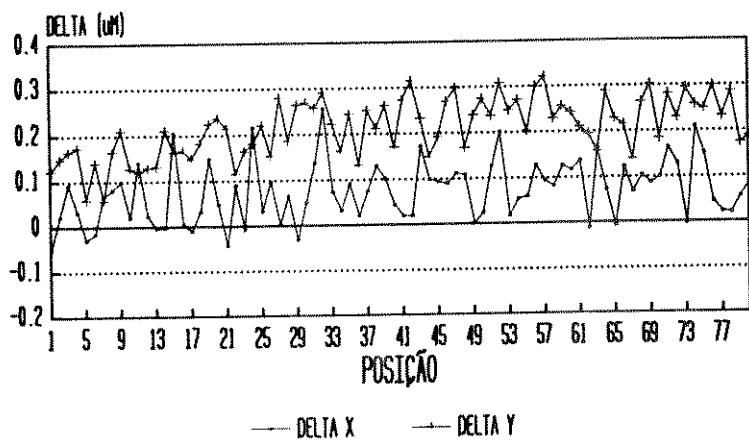


fig 2.5.27

Figura 2.5.27. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 6A coluna da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 6C coluna da esquerda

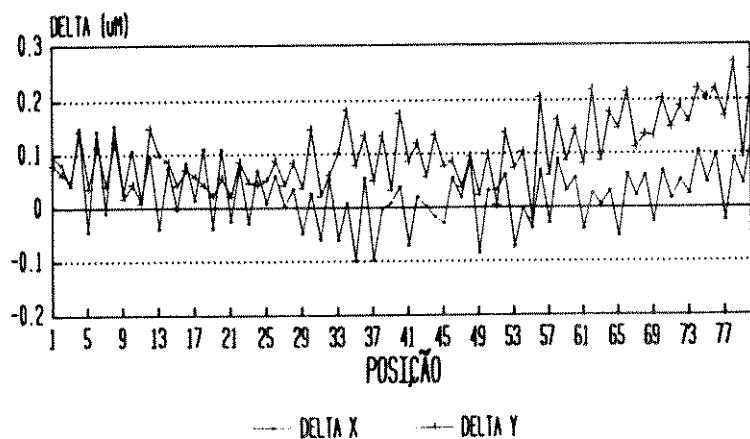


fig 2.5.30

Figura 2.5.30. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 6C coluna da esquerda.

Variação da largura de linha
induzida pelo processo
estrutura 7C coluna da esquerda

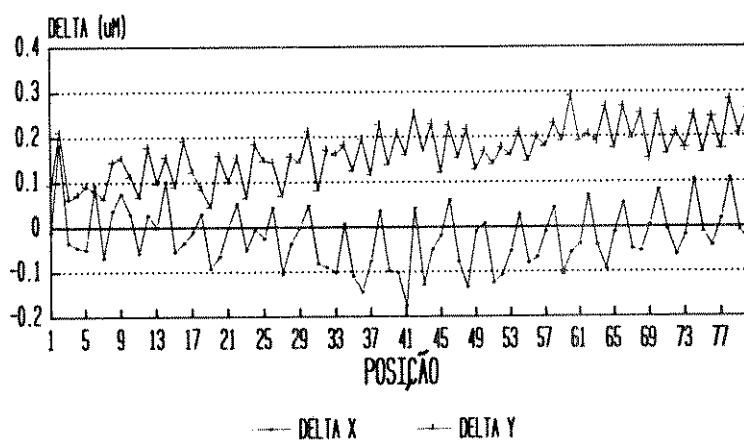


fig 2.5.31

Figura 2.5.31. Variação da largura de linha induzida pelo processo para a estrutura 7C coluna da esquerda.

Apresentamos na tabela 2.5.3.1 um resumo dos resultados obtidos com os valores médios da variação para cada estrutura de teste.

	delta X		delta Y		
	média (μm)	σ (μm)	média (μm)	σ (μm)	
D :1A :	-0.252	0.024	-0.203	0.030	
I :2A :	-0.086	0.040	0.116	0.046	
R :4A :	-0.045	0.021	-0.124	0.023	
E :5A :	-0.058	0.018	-0.047	0.021	
I :6A :	0.051	0.031	0.207	0.046	
T :6C :	0.031	0.035	0.115	0.037	
A :7C :	-0.014	0.035	0.192	0.045	
E :1A :	-0.252	0.021	-0.185	0.027	
S :2A :	-0.075	0.035	0.165	0.031	
Q :4A :	-0.030	0.014	-0.112	0.017	
U :5A :	-0.067	0.017	-0.044	0.022	
E :6A :	0.074	0.026	0.215	0.046	
R :6C :	0.028	0.031	0.103	0.046	
D :7C :	-0.022	0.031	0.167	0.042	
A :					

TABELA 2.5.3.1

Ao deduzirmos a equação 2.3.8, foi considerado que o fator que altera a largura de linha projetada é o "offset" do processo e que o seu valor é independente da dimensão da estrutura. Esta afirmação é verdadeira desde que não tenhamos a ocorrência de outro fator que afete a largura de linha e que seja dependente das dimensões envolvidas. Este é o caso do efeito de proximidade e do astigmatismo do feixe, que estão presentes em todas as estruturas.

Desta maneira, os resultados obtidos para o desvio da largura de linha induzido pelo processo foram mascarados pelo efeito de proximidade e pelo astigmatismo do feixe, tornando sem efeito a análise destes resultados.

CAPÍTULO 3

O ERRO DE OVERLAY

3.1 Estrutura de teste proposta

A estrutura de teste proposta para avaliação do erro de overlay foi projetada de maneira a aproveitar uma das características do processo de fabricação de circuitos integrados pela tecnologia CMOS, que é o auto alinhamento das regiões de dreno e fonte com a porta por meio da implantação destas regiões utilizando a porta de polissilício como máscara. Desta maneira as dimensões das regiões do dreno e da fonte são função do desalinhamento entre as máscaras de difusão e a máscara de definição da região de porta dos transistores CMOS.

A estrutura mostrada na figura 3.1.1, consiste na definição de um resistor na região ativa N que após a implantação iônica através de uma barra definida no polissilício, resulta em dois resistores cujos valores são função do desalinhamento entre a máscara de definição do resistor na região ativa e a máscara de definição da barra de polissilício. Se Δ for o desalinhamento entre as máscaras de definição do resistor e a de definição da barra, W a largura do resistor e L o seu comprimento, os valores dos resistores resultantes à direita e à esquerda da barra de polissilício podem ser calculados como:

$$R_d = R_s * L / (W + \Delta) \quad (3.1.1)$$

$$R_e = R_s * L / (W - \Delta) \quad (3.1.2)$$

O valor de Δ pode ser obtido em função de R_d e R_e

$$\Delta = 0.5 * R_s * L * (1/R_e) - (1/R_d) \quad (3.1.3)$$

Portanto, para obtermos o valor do erro de overlay é necessário medir-se os valores dos resistores R_d , R_e e R_s .

Esta estrutura pode ser repetida de maneira a poder-se avaliar o erro de overlay nas direções X e Y.

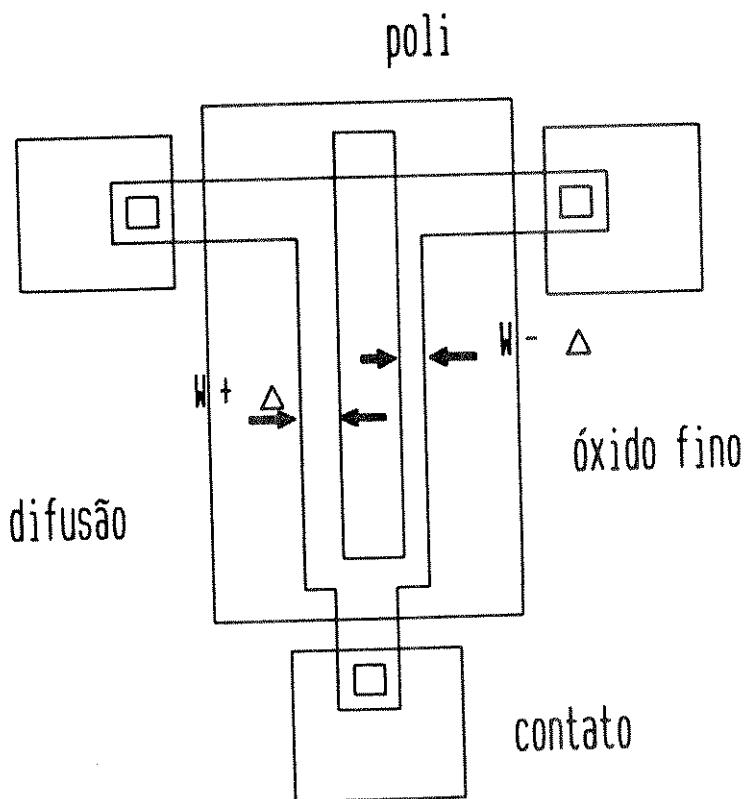


fig. 3.1.1

Figura 3.1.1 Estrutura de teste para medida do erro de overlay em circuitos com tecnologia CMOS.

A estrutura de teste proposta para medida de overlay consiste da composição de quatro estruturas para medida de overlay de maneira a possibilitar a avaliação deste erro na direção X e Y. A figura 3.1.2 apresenta a estrutura de teste proposta. Com esta estrutura é possível determinarmos o deslocamento, a rotação e a distorção causadas à estrutura pelo erro de overlay do equipamento de escrita por feixe eletrônico

A estrutura de teste proposta recebeu o nome de estrutura 1B e foi distribuída no circuito de teste de maneira a compor uma estrutura por quadrante, posicionada no centro do quadrante.

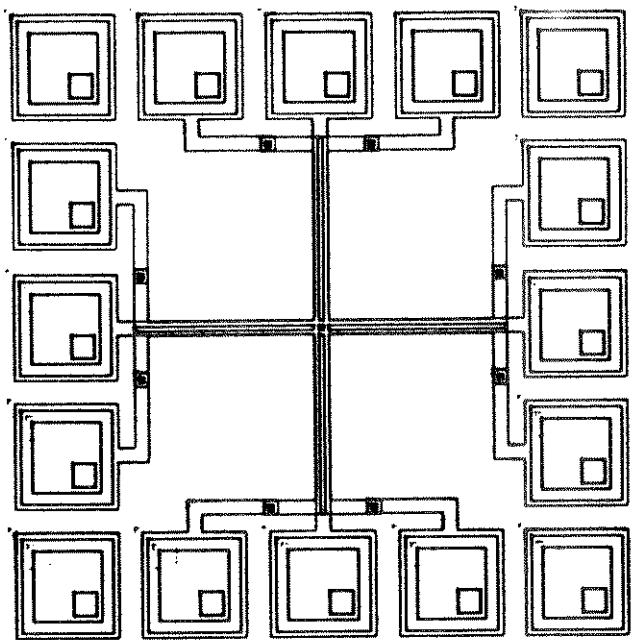


Figura 3.1.2 Estrutura de teste proposta para a avaliação do erro de overlay.

3.2. O erro do método de avaliação do erro de overlay

Para a determinação do erro do método proposto é necessário a determinação do erro do método de obtenção da resistência de folha, e do erro do método de obtenção dos resistores R_d e R_e .

A equação 3.1.3, que apresenta o cálculo do erro de overlay para a estrutura de teste é semelhante a equação (2.3.5.15) que expressa o cálculo da largura de linha em estruturas tipo ponte, e o erro do cálculo de overlay assume a mesma expressão do erro da determinação da largura de linha mostrado na equação (2.4.16).

O erro do método proposto pode portanto ser calculado como sendo :

$$(\sigma\Delta/\Delta)^2 = (\sigma R_s/R_s)^2 + (\sigma L/L)^2 + (\sigma I/I)^2 + (\sigma V/V)^2$$

(3.2.1)

Como o método de medida do erro de overlay é idêntico ao método empregado na determinação da largura de linha, o valor do erro do método de determinação do erro de overlay apresenta o mesmo valor.

3.3 Os procedimentos das medidas e a análise dos resultados obtidos

Para a avaliação do erro de overlay nas estruturas propostas, empregamos os mesmos equipamentos utilizados para a avaliação da resistência de folha e da largura de linha. Como para a determinação do erro de overlay é necessário a medida de resistores gravados na difusão, o mesmo esquema básico de medidas com fontes de corrente e medidores de tensão, foi utilizado. O esquema adotado está mostrado na figura 3.3.1, detalhado para medida no eixo X. Com este esquema foram medidos os dois resistores de cada braço da estrutura totalizando oito resistores medidos para cada estrutura. As medidas foram realizadas utilizando-se o equipamento HP 4145 acoplado via interface GP-IB a um microcomputador como já descrito. Desta maneira foram medidas 4 estruturas por circuito em 20 circuitos para cada coluna, totalizando 1280 medidas realizadas.

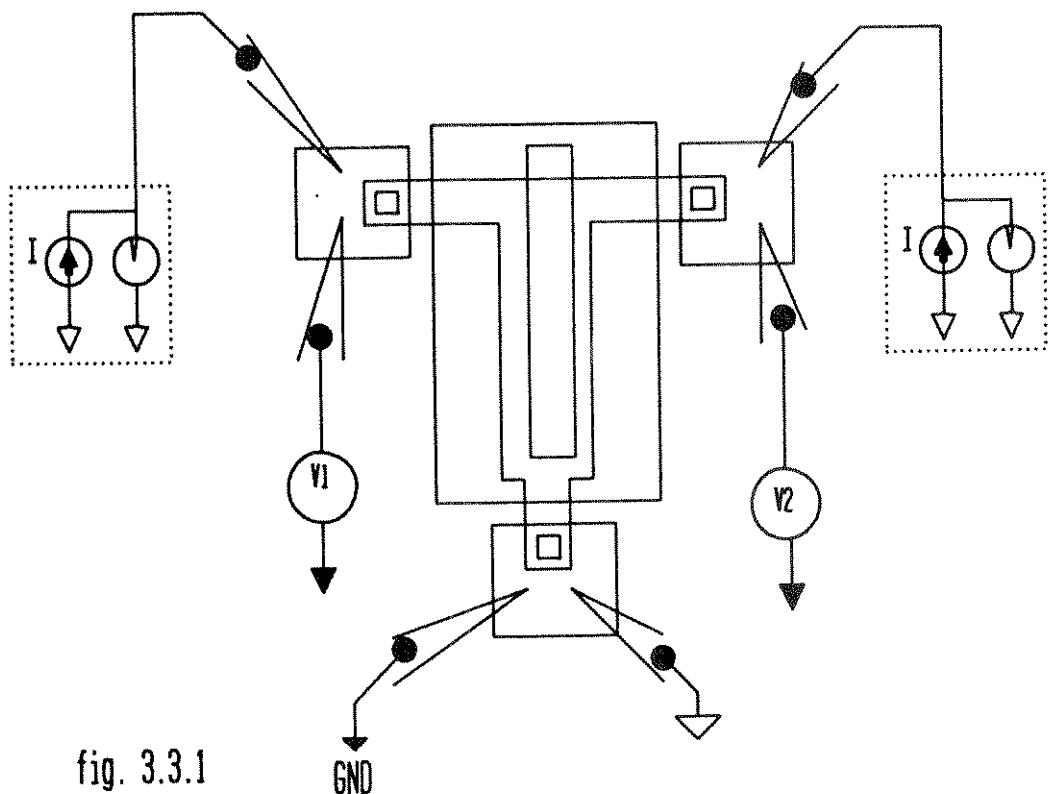


fig. 3.3.1

Figura 3.3.1 Esquema utilizado para medida do erro de overlay.

O erro de overlay foi calculado através da equação (3.1.3) obtendo-se assim dois valores de erro em X e dois em Y. A partir destes valores, foi calculado o deslocamento relativo entre os níveis de difusão e de polissilício tendo como referência o centro dos eixos de simetria da estrutura.

Os resultados obtidos para o deslocamento foram representados sob a forma de vetores cujos módulos e ângulos correspondem ao deslocamento composto pelos deslocamentos nas direções X e Y.

A figura 3.3.2 mostra esquematicamente os deslocamentos relativos, sob forma de vetor, para cada quadrante nos 20 circuitos avaliados para as colunas da direita e da esquerda.

Além do deslocamento foi também calculada a rotação relativa dos eixos da estrutura. Outro parâmetro importante foi obtido da rotação dos eixos, que é a não ortogonalidade causada por distorções no sistema de posicionamento relativo feixe/mesa.

Com base nos dados de rotação obtidos foi construído um gráfico que apresenta os ângulos de rotação dos eixos X e Y em função da posição da estrutura na lâmina, que é mostrado na figura 3.3.3.

A diferença dos ângulos de rotação das estruturas que representa a distorção dos eixos ortogonais é mostrada na figura 3.3.4.

	E	D		E	D		E	D
01			08	14	///	///
02	.		09	;		15	///	---
03	:		10	;;	..	16	--	--
04	;	:	11	//	//	17	--	--
05	..	:	12	//	//	18
06	..	:	13	//	//	19	--	--
07	--	:				20	--	--

Figura 3.3.2 Representação esquemática dos deslocamentos relativos, sob forma de vetor, para cada quadrante nos 20 circuitos avaliados para as colunas da direita e da esquerda.

Rotacão das estruturas Estrutura 1B

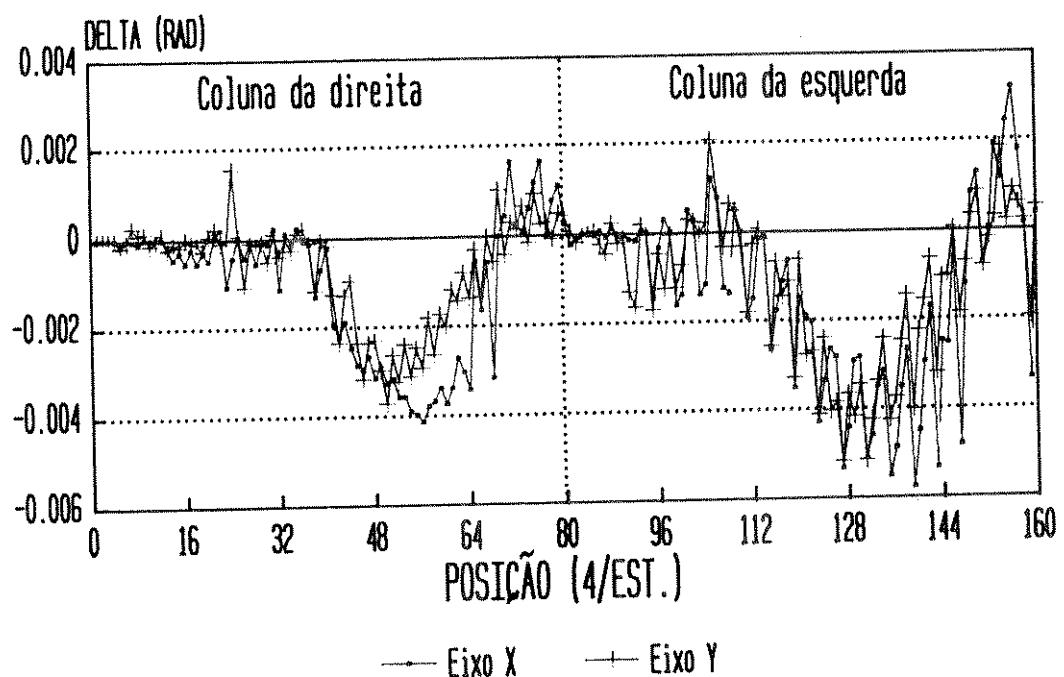


fig 3.3.3

Figura 3.3.3 Ângulos de rotação dos eixos X e Y em função da posição da estrutura na lâmina.

Distorção das estruturas Estrutura 1B

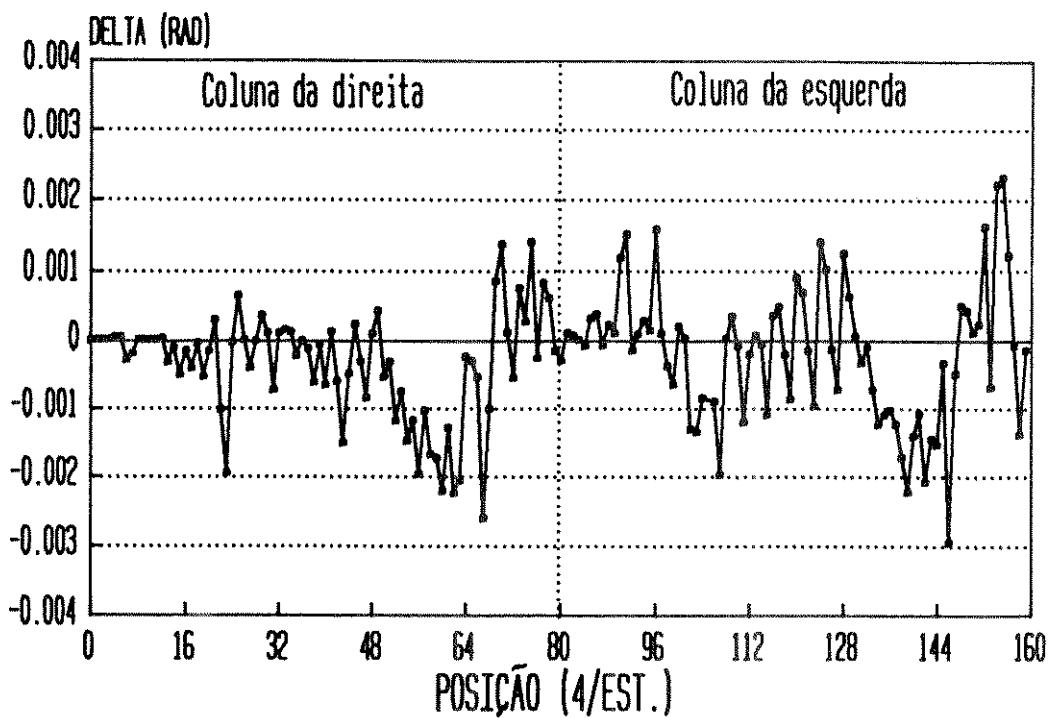


fig 3.3.4

Figura 3.3.4 Diferença dos ângulos de rotação das estruturas que representa a distorção dos eixos ortogonais.

Ao analisarmos o erro de overlay devemos levar em conta que as estruturas foram construídas utilizando duas colunas da periferia da lâmina, o que representa uma condição bastante desfavorável, pois é nas periferias que estes erros são maiores, e não se pode deduzir um comportamento global para o equipamento de litografia.

Uma análise detalhada da figura 3.3.2, permite-nos verificar que os erros de overlay de deslocamento são maiores na metade inferior das colunas diminuindo para as extremidades superiores e inferiores. O erro de overlay máximo observado corresponde a um deslocamento de $-0.662 \mu\text{m}$ na direção X e $-0.644 \mu\text{m}$ na direção Y. Cabe notar que estes valores, apesar de bastante elevados se considerarmos as precisões inerentes aos equipamentos de escrita por feixe de elétrons, estão dentro do permitido pela regra de projeto imposta pelo fabricante.

O gráfico da figura 3.3.3 mostra um comportamento semelhante para a rotação relativa dos eixos da estrutura. Verifica-se que a coluna da esquerda apresenta valores de rotação maiores do que os apresentados pela coluna da direita. Neste gráfico pode-se obter a posição do circuito medido pela divisão por quatro dos valores representados na ordenada, correspondendo a posição 80 ao vigésimo circuito de teste da coluna da direita e a posição 160 ao vigésimo circuito de teste da coluna da esquerda.

A figura 3.3.4 mostra a distorção causada pela não ortogonalidade entre os eixos de rotação. Verifica-se que esta distorção ocorre nas mesmas regiões já citadas.

Das análises anteriores podemos concluir que o fabricante não adota estratégia de alinhamento com marcas localizadas no interior dos circuitos, mas sim marcas globais situadas na periferia da lâmina. Uma inspecção visual por microscópio posterior confirmou esta suposição, pois foram observadas marcas de alinhamento apenas na periferia da lâmina.

Esta estratégia foi adotada pelo fabricante com base nos valores de erro de overlay permitida pela regra de projeto, e pela produtividade que é majorada com a diminuição do tempo global necessário para a detecção das marcas de alinhamento.

Uma evolução no processo para litografias de dimensões abaixo de 1 μm certamente provocará numa mudança da estratégia adotada para o alinhamento, implicando numa redução na produtividade do processo.

A DENSIDADE DE DEFEITOS

4.1 Estrutura de teste proposta

A estrutura proposta para avaliação da densidade de defeitos consiste basicamente de um conjunto contendo uma serpentina sensora posicionada entre duas estruturas tipo pente interdigitadas, definida litograficamente em um substrato condutor, como mostra a figura 4.1.1.

A detecção de defeitos é feita forçando-se a passagem de corrente entre dois terminais da estrutura e medindo-se a diferença de potencial entre estes terminais. Defeitos relacionados com circuito aberto são indicados por um alto valor na diferença de potencial entre os terminais da serpentina. Defeitos relacionados com curto-circuito são indicados por um baixo , ou mesmo zero, valor da diferença de potencial entre os terminais das estruturas tipo pente e o da serpentina.

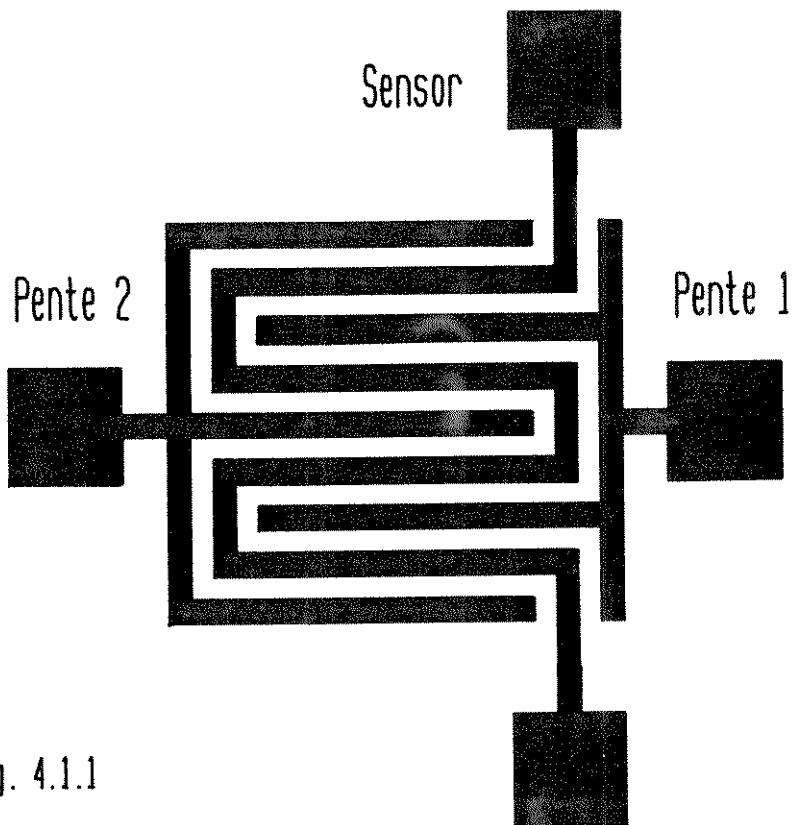


fig. 4.1.1

Figura 4.1.1 Estrutura básica para avaliação da densidade de defeitos.

Três parâmetros são importantes na avaliação da densidade de defeitos, a área coberta pela estrutura de teste, o espaçamento entre a serpentina e as estruturas tipo pente e a largura da linha que forma a serpentina. No caso das estruturas de teste propostas, o espaçamento entre as linhas e a sua largura mínima foram limitadas pelas regras de projeto impostas pela fundição utilizada para a fabricação dos circuitos. A regra de projeto específica que a menor dimensão, bem como o menor espaçamento permitido é de 2 μm para os níveis de polissilício e de metal 1 onde foram definidas as estruturas de teste. Devido a esta limitação, o menor defeito fatal possível de ser detectado pela estrutura de teste é de 2 μm . A utilização de dimensões inferiores à regra de projeto levaria a detecção de defeitos não necessariamente causados por contaminação, confundindo-os com os defeitos inerentes aos limites do processo.

As estruturas como propostas detectam a presença de um defeito fatal mas não são capazes de qualificar a natureza deste. Uma vez detectado o defeito e conhecida a sua posição dentro do circuito, técnicas de inspeção ópticas ou por microscópio eletrônico complementam o método, qualificando a sua natureza e indicando a sua provável origem.

A densidade de defeitos indicada por esta estrutura representa a presença de defeitos fatais por unidade de área, pois esta não detecta a ocorrência múltipla de um mesmo tipo de defeito na área inspecionada.

Ao se distribuir a estrutura de teste por toda a lâmina processada, o número de estruturas que indicarem defeitos fatais resultará no rendimento global do processo de fabricação.

A figura 4.1.2 mostra a estrutura de teste proposta para avaliação da densidade de defeitos. Ela é composta por quatro regiões sensoras separadas pela estrutura para medida de largura de linha já comentada. Cada região sensora define uma área de $32400 \mu\text{m}^2$, ou 0.000324 cm^2 . Foram construídas em polissilício em um mesmo quadrante duas estruturas idênticas sob o aspecto de detecção da densidade de defeitos. Estas estruturas foram identificadas como 5A e 6A. No nível de metal 1 foram construídas também duas estruturas idênticas por quadrante, 6C e 7C. A estrutura 6C foi construída sobre uma estrutura periódica com linhas e espaços de $2\mu\text{m}$ em polissilício, de maneira a se estudar a influência da topografia no aparecimento de defeitos fatais. A figura 4.1.3 mostra a estrutura 6C. A estrutura 7C é idêntica a esta, sem a estrutura periódica em polissilício.

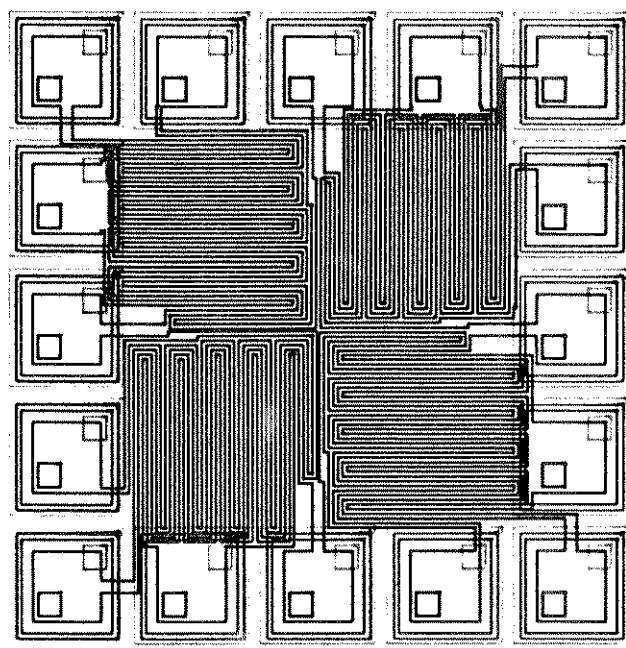


Figura 4.1.2 Estrutura de teste proposta para avaliação da densidade de defeitos.

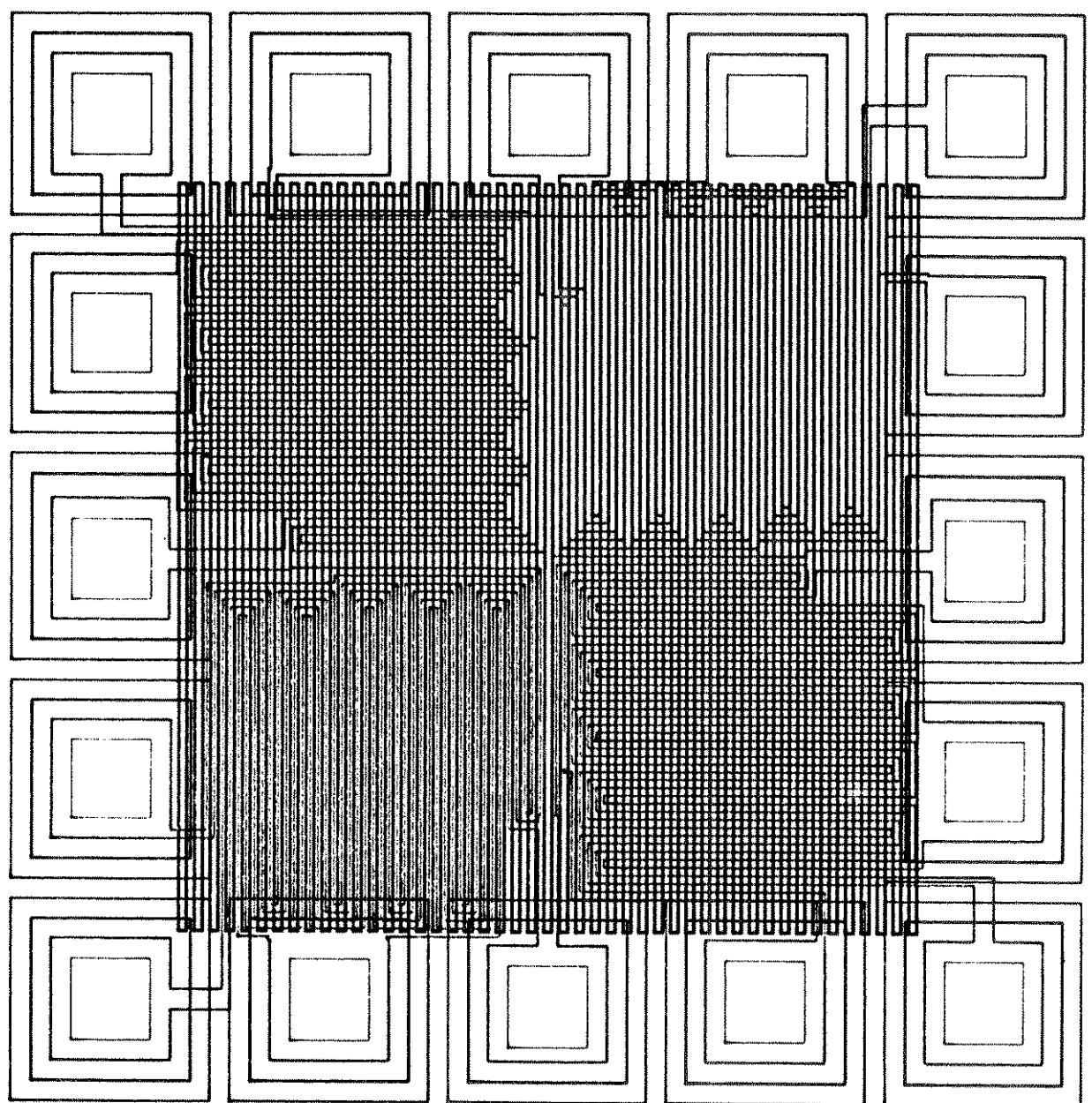


Figura 4.1.3 Estrutura 6C para detecção de defeitos no nível de metal 1 co estrutura periódica de polissilício para indução de defeitos.

4.2 Os procedimentos das medidas e análise dos resultados obtidos

Para a avaliação de defeitos na estrutura proposta foi utilizado o equipamento HP 4145, que foi programado para realizar o teste em duas etapas.

A primeira etapa consistiu na detecção de defeitos relacionados com circuito aberto. Para este teste utilizou-se apenas um canal do HP 4145 programado como fonte de corrente para cada região sensora da estrutura de teste, permitindo a avaliação imediata de toda a estrutura. A figura 4.2.1 mostra o esquema de medida utilizado para a avaliação dos defeitos relacionados com circuito aberto.

A segunda etapa consistiu na detecção de defeitos relacionados com curto-circuito. Para este teste utilizou-se a mesma estratégia da etapa 1, aplicada a outro esquema de medida. A figura 4.2.2 mostra o esquema de medida utilizado para a avaliação dos defeitos relacionados com curto-circuito.

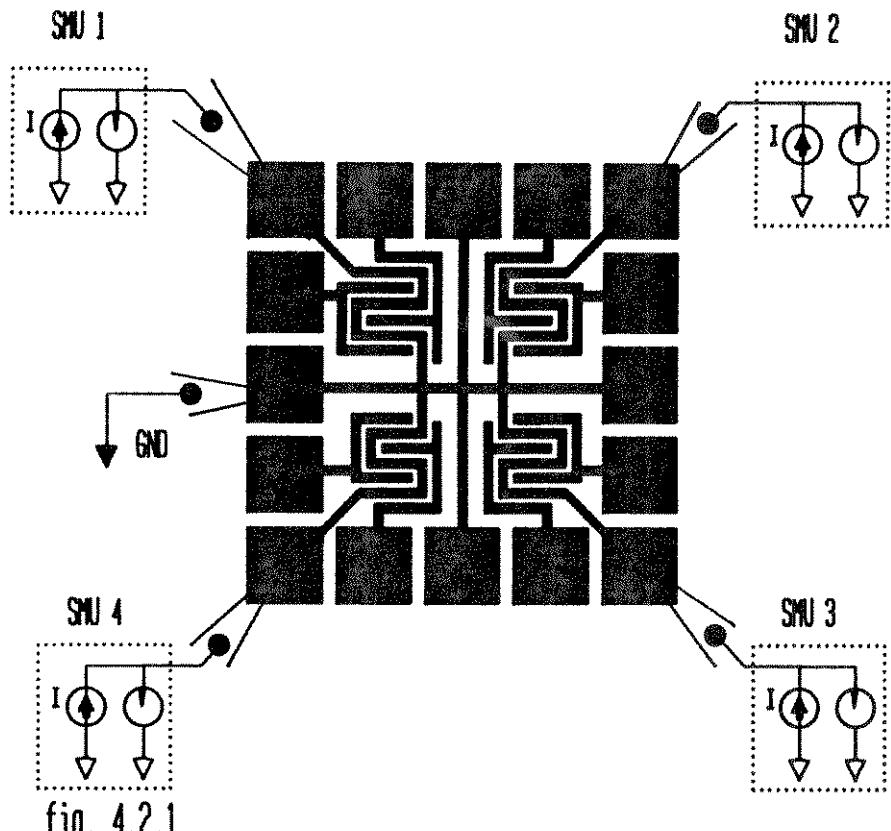


Figura 4.2.1 Esquema de medida utilizado para avaliação de defeitos relacionados com circuito aberto.

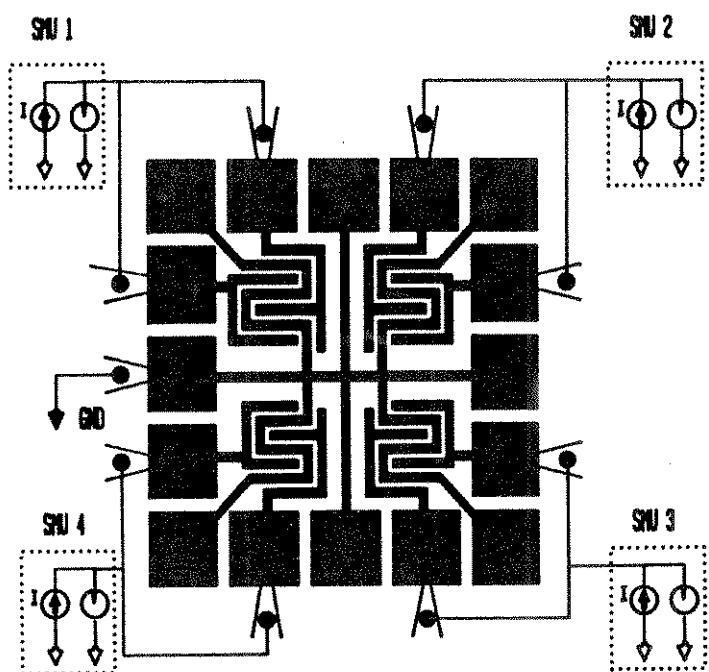


fig. 4.2.2

Figura 4.2.2 Esquema de medida utilizado para avaliação de defeitos relacionados com curto-círcito.

Para a avaliação de defeitos foram medidos todos os circuitos presentes na lâmina disponível, resultando um total de 200 medidas por tipo de defeito.

Apresentamos na tabela 4.2.1 os circuitos e as estruturas que apresentaram defeitos relacionados com circuito aberto.

Na tabela 4.2.2 apresentamos os circuitos e estruturas em que foram detectados defeitos relacionados com curto-círcuito.

D02-SE7C-metal 1, canto superior esquerdo.

D25-ID6C-metal 1, canto inferior direito.

D25-SD6A-polissilício, canto superior direito.

D25-SD6C-metal 1, canto superior direito.

D25-SD7C-metal 1, canto superior direito.

Tabela 4.2.1 Circuitos e estruturas que apresentaram defeitos relacionados com circuito aberto.

E24-ID7C- metal 1, canto inferior direito.

D24-IE7C- metal 1, canto inferior esquerdo.

D24-ID5A- polissilício, canto inferior direito.

D24-ID7C- metal 1, canto inferior direito.

D24-ID6A- polissilício, canto inferior direito.

D24-SD7C- metal 1, canto superior direito.

D25-SE6A- polissilício, canto superior esquerdo.

D25-ID6A- polissilício, canto inferior direito.

D25-ID6C- metal 1, canto inferior direito.

D25-SD5A- polissilício, canto superior direito.

D25-SD6A- polissilício, canto superior direito.

D25-SD6C- metal 1, canto superior direito.

D25-SD7C- metal 1, canto superior direito.

Tabela 4.2.2 Circuitos e as estruturas que apresentaram defeitos relacionados com curto-círcuito.

As estruturas que apresentaram defeito foram inspecionadas utilizando-se microscópio óptico e todos os defeitos detectados foram confirmados pela inspecção visual.

Das tabelas 4.2.1 e 4.2.2, pode-se constatar que os circuitos que apresentaram o maior número de defeitos de ambos os tipos foram os circuitos situados na borda inferior da lâmina. Esta posição corresponde aos circuitos D24 e D25. Nestes circuitos foram detectados defeitos relacionados com circuito aberto e também curto-circuito. A inspecção óptica revelou a existência de uma região com falhas de litografia que causaram a não definição de parte das estruturas presentes no circuito de teste. Os defeitos detectados no circuito de teste D24 foram causados pelo rompimento proposital de linhas, ocorrido durante os testes que foram realizados para determinação do limite máximo de corrente que uma linha pode suportar. Os defeitos detectados no circuito D02 foram causados pelo deslocamento acidental de uma das ponteiras utilizadas para acessar os contatos das estruturas. O metal arrastado pela ponteira provocou o curto-circuito detectado posteriormente pela estrutura de teste.

Os resultados apresentados demonstram a habilidade das estruturas em detectar defeitos fatais presentes na região sensora. Pela natureza dos defeitos detectados podemos concluir que, excetuando-se a região da borda inferior da lâmina, o processo aparenta ter baixa densidade de defeitos maiores que $2 \mu\text{m}$. Se considerarmos os resultados para a borda da lâmina podemos avaliar a densidade de defeitos como sendo da ordem de 12 defeitos/cm^2 . Este valor não representa a densidade de defeitos média correspondente ao processo, devido a presença da região defeituosa que é uma ocorrência atípica. Outro fator que não nos permite deduzir a real densidade de defeitos do processo, é a área total coberta pelas estruturas de teste. Para os 50 circuitos de teste, com 8 estruturas de teste cada, para o nível de metal ou polissilício, a área total coberta é de apenas 0.518 cm^2 .

CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES

5.1 A largura de linha, o overlay e a densidade de defeitos

Neste trabalho apresentamos um conjunto de estruturas elétricas de teste para avaliação de parâmetros litográficos para serem empregadas na avaliação de um processo industrial de fabricação de circuitos integrados.

Três foram os parâmetros investigados. A largura de linha, o overlay e a densidade de defeitos.

Os circuitos de teste foram produzidos em um fabricante de circuitos integrados no exterior como parte do Projeto Multusuário PMUCMOS 4, coordenado pelo Centro Tecnológico para a Informática.

Foram fabricados 50 circuitos de teste composto pelas estruturas de teste, distribuídos em duas colunas de 25 circuitos, dos quais foram avaliados 20 circuitos por coluna.

Os resultados obtidos nos permitiram :

- 1) Avaliar a precisão do método de medidas de parâmetros de litografia através de estruturas elétricas de teste.
- 2) Avaliar a efetividade das estruturas propostas em revelar através dos parâmetros básicos de litografia, as estratégias empregadas pelo fabricante e os parâmetros do processo litográfico.

O método de medida de largura de linha através de estruturas tipo ponte, demonstrou ser simples, rápido e preciso.

A simplicidade advém do fato de serem apenas necessários um microvoltímetro e uma fonte de corrente para a medida da resistência de folha e da resistência da linha. A utilização de estruturas de tamanho e posicionamento padronizados, tornam simples o problema de acesso aos terminais da estrutura dispensando o uso de microposicionadores.

A rapidez está relacionada com o número de medidas por unidade de tempo, que está limitada basicamente pelo tempo necessário para se posicionar a estrutura sob teste, adicionado ao tempo de programação dos equipamentos de medida. A adoção de equipamentos de testes automáticos dedicado às estruturas de teste, tendem a reduzir estes tempos de maneira a permitir que um grande número de medidas seja realizado, permitindo a avaliação estatística dos resultados obtidos.

A precisão do método depende das precisões dos equipamentos utilizados. O valor de corrente empregado, depende do material em que é construída a estrutura. Os valores de corrente devem ser escolhidos em função da resolução do voltímetro empregado e da dissipação de potência na estrutura.

O método de medida de overlay demonstrou a mesma versatilidade e precisão do método de medida de largura de linha, por terem o mesmo princípio básico. Como característica principal esta estrutura permitiu a avaliação do erro de overlay, sem alterar a sequência do processo.

O método de medida da densidade de defeitos mostrou que é capaz de detectar defeitos fatais ao funcionamento de um circuito integrado.

A sensibilidade deste método está relacionada com o espaçamento e a largura das linhas que formam a estrutura, e também a área coberta pelo elemento sensor. Portanto, para uma avaliação da densidade de defeitos inerentes a um processo, é necessário um projeto específico da estrutura visando a mínima dimensão que pode ser definida pelo processo litográfico e a máxima área sensora.

As estruturas para avaliação da largura de linha, foram projetadas de maneira a fornecer informações sobre os parâmetros litográficos, e sobre as estratégias adotadas pelo fabricante nas etapas de definição litográfica. Através delas pudemos concluir que o fabricante não adota mecanismos de correção do efeito de proximidade, ajustando o seu processo para cumprir as regras de projeto. Concluimos também que o fabricante otimiza seu processo para as linhas definidas no metal 1. Os desvios relacionados com o processo de revelação e ataque do polissilício não puderam ser determinados devido ao mascaramento introduzido pelo efeito de proximidade, e pelo astigmatismo do feixe.

As estruturas para determinação do erro de overlay, permitiram avaliar a estratégia empregada pelo fabricante no alinhamento dos níveis litográficos, pelo emprego de marcas de alinhamento na periferia da lâmina, introduzindo erros de overlay provavelmente causados por distorção do sistema eletroóptico, precisão da mesa posicionadora e instabilidade térmica da câmara.

A estrutura de avaliação da densidade de defeitos permitiu verificar que o processo utilizado pelo fabricante possue aparentemente um alto rendimento, mas cuidados devem ser tomados pelos fabricantes de maneira a não permitir a inutilização de uma região da lâmina com um erro de grandes dimensões como o detectado pela estrutura de teste.

Com base na experiência adquirida no transcorrer deste trabalho, novas estruturas podem ser projetadas e as apresentadas reprojetadas, de maneira a possibilitar a investigação de parâmetros de processo, nas várias etapas, para processos submicrométricos onde as técnicas de litografia empregadas são de grande interesse.

Como conclusão final, as estruturas elétricas de teste se mostraram adequadas a avaliação de parâmetros litográficos, permitindo a obtenção de informações concernentes ao processo de fabricação de circuitos integrados utilizado pelo fabricante, que poderão vir a ser utilizadas na implantação de um processo de fabricação de circuitos integrados com tecnologia de litografia por feixe eletrônico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] AVATAR S. OBERAI. "Litography Challenges of the future" - Solid State Technology, Sept/1987.
- [2] D. R. HERRIOTT and G.R. BREWER. "Electron-beam technology in microelectronics fabrication" Academic Press, 1980, pag. 143.
- [3] D. EHRHARDT, H.T. VIERHAUS, N. ARNDT, E. FROSCHLE. "Compensation of the proximity effect by exposure with a circularly deflected defocused E-beam."
- [4] J.S. GREENEICH. "Electron-beam technology in microelectronics fabrication" - Academic Press, 1980, pag. 71.
- [5] T.H.P. CHANG. "Proximity effect in Electron-beam lithography" - J.Vac. Science Technology, vol. 12, nº 6, Nov/Dec 1975.
- [6] S.A. RISHTON and D.P. KERN. "Point exposure distribution measurements for proximity correction in electron beam lithography on a sub-100mm scale" - J.Vac. Science Technology - B5(1), Jan/Feb 1987.
- [7] M. PARIKH and D.F. KAYSER. IBM Research Rep. RJ2261, 1978.
- [8] O.W. OTTO and A.K. GRIFFITH. J.Vac. Science Technology - B, vol. 6, nº1, Jan/Feb, 1988.
- [9] H.E. HASLAN and J.F. MacDONALD. "Applying Transform based proximity corrections to electron-beam lithography with 0,2um features" J.Vac. Science Technology - B6(1), Jan/Feb 1988.
- [10] H.T. VIERHAUS. "Electron-Beam Lithography Proximity Effect Correction using the CLEER Approach" presentation at CTI in 1988.
- [11] T.H.P. CHANG. J.Vac. Science Technology, 12, 6, 1271 (1975).
- [12] S.A. RISHTON and D.P. KERN. J. Vac. Science Technology B5, 135 (1987).
- [13] BADIH EI-RAREH and R.J. BOMBARD. "Introduction to VLSI Silicon Devices" - Klewer Academic Publishers, 1986.

- [14] L.J. VAN DER PAUW. "A method of measuring the resistivity and hall coefficient on lamellae of arbitrary shape". Phillips Tech. Rev., 20: 220-224(1959).
- [15] BADIH EI-RAREH and R.J. BOMBARD. "Introduction to VLSI Silicon Devices" - Kluwer Academic Publishers, 1986.
- [16] J.M. DAVID and M.G. BUEHLER. "A numerical analysis of various cross sheet revision test structures". SSE - vol. 20, n° 6-E.
- [17] H. BOHLEN, W. KULCKE. "Evaluation of Level-to-level overlay in lithography Systems". Solid State Technology FEB, 1990, pag. 59.
- [18] D.S. PERLOFF. "A Van der Pauw Resistor Structure for determining mask superposition errors on semiconductor slices". Solid State Electronics, Vol. 21, pag. 1013-1018, 1978.
- [19] J.P. BALLANTYNE. "Electron-beam technology in microelectronics fabrication" - Academic Press, 1980, pag. 265.

APÊNDICE I

**TABELA DAS MEDIDAS DE RESISTÊNCIA DE FOLHA
ATRAVÉS DE ESTRUTURAS VAN DER PAUW**

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA EM ESTRUTURAS VAN DER PAUW

	POLY				DIFUSAO N				ALUMINIO				
	R1	R2	R2/R1	RS	R1	R2	R1/R2	RS	R1	R2	R2/R1	RS	
D01													
SE	16,90	19,55	1,157	18,23	53,15	50,50	1,052	51,83	0,058	0,065	1,121	0,062	
IE	19,70	20,13	-1,022	19,92	55,17	54,36	1,015	54,77	0,053	0,072	1,358	0,063	
ID	17,49	20,74	1,186	19,12	55,49	52,71	1,053	54,10	0,064	0,058	1,103	0,061	
SD	18,75	17,87	1,049	18,31	54,15	54,71	1,010	54,43	0,051	0,075	1,471	0,063	
D02													
SE	20,13	21,03	1,045	20,58	44,15	41,94	1,053	43,05	0,054	0,064	1,185	0,059	
IE	18,31	20,95	1,144	19,63	42,10	42,87	1,018	42,49	0,064	0,060	1,067	0,062	
ID	20,58	19,30	1,066	19,94	44,01	41,97	1,049	42,99	0,062	0,063	1,016	0,063	
SD	20,40	20,47	1,003	20,44	41,61	43,31	1,041	42,46	0,057	0,066	1,158	0,062	
D03													
SE	20,88	18,93	1,103	19,91	44,11	42,24	1,044	43,18	0,069	0,054	1,278	0,062	
IE	17,45	21,31	1,221	19,38	41,75	43,70	1,047	42,73	0,049	0,078	1,592	0,064	
ID	20,31	20,35	1,002	20,33	43,55	42,90	1,015	43,23	0,061	0,063	1,033	0,062	
SD	19,99	18,60	1,075	19,30	41,89	43,27	1,033	42,58	0,044	0,082	1,864	0,063	
D04													
SE					44,63	42,34	1,054	43,49	0,044	0,085	1,932	0,065	
IE	18,35	21,33	1,162	19,84	42,16	43,68	1,036	42,92	0,057	0,067	1,175	0,062	
ID	22,82	20,10	1,135	21,46	43,73	43,16	1,013	43,45	0,060	0,063	1,050	0,062	
SD	18,10	20,96	1,158	19,53	43,11	42,57	1,013	42,84	0,065	0,059	1,102	0,062	
D05													
SE	19,37	20,96	1,082	20,17	45,69	41,62	1,098	43,66	0,060	0,064	1,067	0,062	
IE	19,86	22,51	1,133	21,19	42,00	44,19	1,052	43,10	0,055	0,059	1,255	0,062	
ID	22,16	19,38	1,143	20,77	43,77	43,53	1,006	43,65	0,058	0,066	1,138	0,062	
SD	20,47	17,83	1,148	19,15	42,90	43,21	1,007	43,06	0,050	0,074	1,480	0,062	
D06													
SE	20,14	19,22	1,048	19,48	45,51	42,02	1,083	43,77	0,056	0,073	1,304	0,065	
IE	22,17	20,95	1,058	21,36	41,60	44,73	1,075	43,17	0,055	0,079	1,436	0,067	
ID	19,51	21,77	1,116	20,64	44,69	42,77	1,045	43,73	0,065	0,060	1,083	0,063	
SD	20,32	22,31	1,098	21,32	42,32	43,97	1,039	43,15	0,047	0,079	1,681	0,063	
D07													
SE	19,87	19,93	1,003	19,90	46,47	41,14	1,130	43,81	0,056	0,070	1,250	0,063	
IE	20,38	20,16	0,989	20,27	43,87	42,53	1,032	43,20	0,054	0,071	1,315	0,063	
ID	20,41	22,45	1,100	21,43	44,44	42,98	1,034	43,71	0,063	0,061	1,033	0,062	
SD	21,34	20,73	1,029	21,04	43,17	43,14	1,001	43,16	0,056	0,067	1,196	0,062	
D08													
SE	19,53	22,24	1,139	20,89	45,96	41,59	1,105	43,78	0,057	0,070	1,228	0,064	
IE	19,87	21,04	1,059	20,46	42,45	43,82	1,032	43,14	0,049	0,080	1,633	0,065	
ID	22,61	21,50	1,052	22,06	45,28	42,13	1,075	43,71	0,058	0,066	1,138	0,062	
SD	20,43	21,97	1,075	21,20	43,51	42,76	1,018	43,14	0,056	0,070	1,250	0,063	
D09													
SE	21,85	21,30	1,026	21,58	45,67	42,00	1,087	43,84	0,059	0,065	1,102	0,062	
IE	20,26	20,26	1,000	20,26	41,94	44,39	1,058	43,17	0,055	0,070	1,273	0,063	
ID	22,94	20,45	1,122	21,70	44,10	43,37	1,017	43,74	0,060	0,063	1,056	0,062	
SD	21,35	21,35	1,000	21,35	42,41	43,90	1,035	43,16	0,060	0,063	1,050	0,062	
D10													
SE	19,91	23,06	1,155	21,46	45,16	42,45	1,064	43,81	0,064	0,060	1,067	0,062	
IE	20,85	22,38	1,073	21,62	42,93	43,35	1,010	43,14	0,051	0,075	1,471	0,063	
ID	22,67	21,08	1,075	21,88	44,26	43,17	1,025	43,72	0,061	0,063	1,033	0,062	
SD	19,41	21,45	1,105	20,43	42,32	43,94	1,038	43,13	0,047	0,081	1,723	0,064	
D11													
SE	22,29	22,37	1,004	22,33	44,45	42,32	1,055	43,49	0,061	0,062	1,016	0,062	
IE	22,13	22,66	1,024	22,40	41,51	44,13	1,063	42,82	0,060	0,067	1,117	0,064	
ID	21,50	21,55	1,002	21,53	43,18	43,59	1,009	43,39	0,057	0,067	1,175	0,062	

SD	21.48	20.42	1.052	20.95	42.18	43.48	1.031	42.83	0.055	0.069	1.255	0.062
D12												
SE	20.19	21.12	1.046	20.66	45.67	41.23	1.108	43.45	0.063	0.061	1.033	0.062
IE	19.47	21.63	1.111	20.55	41.81	43.78	1.047	42.80	0.050	0.073	1.460	0.062
ID	21.88	20.66	1.039	21.27	44.12	42.63	1.035	43.38	0.053	0.070	1.321	0.062
SD	23.51	19.59	1.200	21.55	42.04	43.63	1.038	42.84	0.055	0.069	1.235	0.062
D13												
SE	18.35	21.22	1.156	19.79	45.59	41.39	1.101	43.49	0.064	0.061	1.049	0.063
IE	21.44	20.62	1.040	21.03	41.71	44.01	1.055	42.86	0.050	0.075	1.500	0.063
ID	21.26	21.00	1.012	21.13	44.67	42.18	1.059	43.43	0.059	0.066	1.119	0.063
SD	19.01	19.87	1.045	19.44	42.62	43.19	1.013	42.91	0.044	0.082	1.864	0.063
D14												
SE	21.95	19.45	1.129	20.70	45.39	41.64	1.090	43.52	0.057	0.068	1.193	0.063
IE	20.78	21.10	1.015	20.94	41.82	43.97	1.051	42.90	0.043	0.085	1.977	0.064
ID	21.00	20.58	1.020	20.79	42.68	44.27	1.037	43.48	0.058	0.068	1.172	0.063
SD	21.78	22.34	1.026	22.06	41.78	44.04	1.054	42.91	0.045	0.082	1.822	0.064
D15												
SE	20.86	19.95	1.046	20.41	43.86	43.15	1.016	43.51	0.061	0.063	1.033	0.062
IE	21.70	20.24	1.072	20.97	42.69	43.26	1.013	42.98	0.053	0.073	1.377	0.063
ID	22.05	20.92	1.054	21.49	44.18	42.75	1.033	43.47	0.058	0.067	1.155	0.063
SD	22.11	20.33	1.088	21.22	42.94	42.99	1.001	42.97	0.049	0.073	1.490	0.061
D16												
SE	22.92	22.42	1.022	22.67	43.95	43.02	1.022	43.49	0.063	0.061	1.033	0.062
IE	21.10	23.26	1.102	22.18	42.42	43.46	1.025	42.94	0.052	0.074	1.423	0.063
ID	21.11	22.27	1.055	21.69	44.56	42.29	1.054	43.43	0.058	0.066	1.138	0.062
SD	22.10	22.65	1.025	22.38	42.83	43.08	1.006	42.96	0.042	0.089	2.119	0.066
D17												
SE	20.91	21.38	1.022	21.15	44.39	42.54	1.043	43.47	0.051	0.074	1.451	0.063
IE	17.55	20.62	1.175	19.09	42.70	43.21	1.012	42.96	0.045	0.083	1.844	0.064
ID	21.43	20.70	1.035	21.07	44.05	42.77	1.030	43.41	0.060	0.065	1.083	0.063
SD	23.19	21.41	1.063	22.30	42.55	43.31	1.018	42.93	0.051	0.074	1.451	0.063
D18												
SE	20.27	19.28	1.051	19.78	45.68	41.47	1.102	43.58	0.059	0.066	1.119	0.063
IE	19.34	23.43	1.222	21.49	42.22	43.88	1.039	43.05	0.053	0.074	1.396	0.064
ID	18.44	23.72	1.286	21.08	43.50	43.62	1.003	43.56	0.058	0.067	1.155	0.063
SD	21.01	23.48	1.118	22.25	42.25	43.87	1.038	43.06	0.050	0.077	1.540	0.064
D19												
SE	19.13	21.80	1.140	20.47	45.77	41.71	1.097	43.74	0.060	0.064	1.067	0.062
IE	20.33	22.09	1.087	21.21	42.59	43.76	1.027	43.18	0.047	0.079	1.681	0.063
ID	20.20	22.15	1.097	21.18	44.23	43.23	1.023	43.73	0.058	0.068	1.172	0.063
SD	22.22	19.60	1.134	20.91	42.83	43.62	1.018	43.23	0.055	0.070	1.273	0.063
D20												
SE	21.35	21.81	1.022	21.58	45.56	42.17	1.080	43.87	0.049	0.079	1.612	0.064
IE	20.36	21.09	1.036	20.73	41.76	44.78	1.072	43.27	0.051	0.077	1.510	0.064
ID	22.80	21.21	1.075	22.01	43.55	44.13	1.013	43.84	0.060	0.064	1.067	0.062
SD	21.70	22.21	1.024	21.96	43.22	43.35	1.003	43.29	0.052	0.073	1.404	0.063
E01												
SE	19.55	20.63	1.055	20.09	47.56	47.06	1.011		0.066	0.056	1.179	0.061
IE	18.80	23.07	1.227	20.94	41.70	43.25	1.037	42.48	0.045	0.080	1.778	0.063
ID	20.05	20.64	1.029	20.35	43.70	42.23	1.035	42.97	0.065	0.057	1.140	0.061
SD	19.69	22.03	1.119	20.86	41.45	43.05	1.039	42.25	0.058	0.064	1.103	0.061
E02												
SE	20.24	21.43	1.059	20.84	44.41	41.88	1.060	43.15	0.070	0.053	1.321	0.062
IE	20.83	21.43	1.029	21.13	41.76	43.63	1.045	42.70	0.054	0.068	1.259	0.061
ID	20.56	20.59	1.001	20.58	42.84	43.61	1.018	43.23	0.052	0.070	1.346	0.061
SD	19.50	18.73	1.041	19.12	42.90	42.42	1.011	42.66	0.049	0.075	1.531	0.062
E03												
SE	19.88	22.82	1.148	21.35	45.20	41.99	1.076	43.60	0.059	0.062	1.051	0.061
IE	21.29	21.33	1.002	21.31	41.45	44.67	1.078	43.06	0.058	0.065	1.121	0.062
ID	19.45	23.04	1.185	21.25	44.03	43.06	1.023	43.55	0.061	0.060	1.017	0.061

SD	20.90	18.50	1.130	19.70	41.60	44.41	1.068	43.01	0.050	0.072	1.440	0.061
E04												
SE	20.23	19.88	1.018	20.06	44.96	42.31	1.063	43.64	0.055	0.068	1.236	0.062
IE	21.02	19.94	1.054	20.48	42.40	43.75	1.032	43.08	0.045	0.080	1.778	0.063
ID	19.14	19.92	1.041	19.53	45.24	41.85	1.081	43.35	0.058	0.063	1.086	0.061
SD	18.12	24.05	1.327	21.09	43.63	42.55	1.025	43.09	0.053	0.071	1.340	0.062
E05												
SE	19.85	22.40	1.128	21.13	44.89	42.44	1.058	43.67	0.068	0.055	1.236	0.062
IE	20.11	21.12	1.050	20.62	43.05	43.09	1.001	43.07	0.043	0.084	1.953	0.064
ID	19.23	21.20	1.102	20.22	44.07	43.22	1.020	43.65	0.054	0.068	1.259	0.061
SD	20.07	22.34	1.113	21.21	42.94	43.31	1.009	43.13	0.046	0.079	1.717	0.063
E06												
SE	20.73	22.22	1.072	21.48	44.90	42.72	1.051	43.81	0.057	0.065	1.140	0.061
IE	17.94	19.36	1.079	18.65	42.28	44.08	1.043	43.18	0.049	0.076	1.351	0.063
ID	20.26	22.68	1.119	21.47	45.73	41.78	1.095	43.76	0.056	0.069	1.232	0.063
SD	21.50	21.20	1.014	21.35	42.43	43.97	1.036	43.20	0.053	0.068	1.236	0.062
E07												
SE	21.78	20.73	1.051	21.26	45.83	41.85	1.095	43.84	0.055	0.069	1.255	0.062
IE	21.16	21.55	1.018	21.36	43.37	43.04	1.008	43.21	0.047	0.078	1.660	0.063
ID	19.95	22.00	1.103	20.98	43.68	43.88	1.005	43.78	0.063	0.064	1.016	0.064
SD	20.55	22.31	1.086	21.43	43.23	42.92	1.007	43.08	0.052	0.071	1.365	0.062
E08												
SE	20.96	21.55	1.028	21.26	44.55	43.21	1.031	43.88	0.055	0.069	1.255	0.062
IE	21.30	22.70	1.066	22.00	42.44	44.00	1.037	43.22	0.055	0.069	1.255	0.062
ID	20.14	22.04	1.094	21.09	44.96	42.55	1.057	43.76	0.062	0.062	1.000	0.062
SD	20.97	23.28	1.110	22.13	43.32	43.16	1.004	43.24	0.056	0.072	1.286	0.064
E09												
SE	20.36	22.72	1.116	21.54	45.27	42.51	1.085	43.89	0.061	0.063	1.033	0.062
IE	21.39	21.45	1.003	21.42	41.71	44.70	1.072	43.21	0.057	0.069	1.211	0.063
ID	20.02	20.98	1.048	20.50	45.10	42.49	1.061	43.80	0.057	0.067	1.175	0.062
SD	21.93	19.39	1.131	20.66	42.56	43.87	1.031	43.22	0.055	0.070	1.273	0.063
E10												
SE	21.81	21.91	1.005	21.86	46.56	41.32	1.127	43.94	0.052	0.074	1.423	0.063
IE	21.53	22.22	1.032	21.88	43.23	43.26	1.001	43.25	0.056	0.074	1.321	0.065
ID	20.90	21.91	1.048	21.41	43.56	44.17	1.014	43.87	0.058	0.067	1.155	0.063
SD	20.23	19.96	1.014	20.10	42.71	43.76	1.025	43.24	0.059	0.067	1.136	0.063
E11												
SE	21.03	22.43	1.067	21.73	44.61	42.58	1.048	43.60	0.057	0.067	1.175	0.062
IE	22.09	21.84	1.011	21.97	42.71	43.12	1.010	42.92	0.042	0.088	2.095	0.065
ID	20.28	22.43	1.106	21.36	44.46	42.54	1.045	43.50	0.060	0.064	1.067	0.062
SD	20.19	21.13	1.047	20.66	42.03	43.77	1.041	42.90	0.045	0.084	1.867	0.065
E12												
SE	18.99	20.52	1.081	19.76	45.58	41.43	1.100	43.51	0.067	0.058	1.155	0.063
IE	23.48	20.63	1.138	22.06	41.62	44.09	1.059	42.86	0.060	0.064	1.867	0.062
ID	22.77	21.07	1.081	21.72	43.80	43.09	1.016	43.45	0.051	0.073	1.431	0.062
SD	23.20	22.54	1.029	22.87	42.70	43.00	1.007	42.85	0.057	0.068	1.193	0.063
E13												
SE	20.75	23.62	1.138	22.19	45.11	41.82	1.079	43.47	0.058	0.068	1.172	0.063
IE	21.26	22.98	1.080	22.13	42.24	43.45	1.029	42.85	0.044	0.088	2.000	0.066
ID	20.82	21.40	1.028	21.11	44.00	42.85	1.027	43.43	0.056	0.070	1.250	0.063
SD	20.05	23.01	1.148	21.53	42.47	43.22	1.018	42.85	0.055	0.070	1.273	0.063
E14												
SE	20.32	19.20	1.058	19.76	45.18	41.75	1.082	43.47	0.054	0.071	1.315	0.063
IE	21.05	23.03	1.094	22.04	42.16	43.57	1.033	42.87	0.047	0.081	1.723	0.064
ID	19.11	23.71	1.241	21.41	44.56	42.21	1.056	43.39	0.062	0.064	1.032	0.063
SD	22.07	19.65	1.123	20.86	42.82	42.92	1.002	42.87	0.050	0.078	1.560	0.064
E15												
SE	20.52	23.44	1.142	21.98	44.64	42.25	1.057	43.45	0.058	0.066	1.138	0.062
IE	22.72	21.67	1.048	22.20	42.25	43.53	1.030	42.89	0.047	0.081	1.723	0.064
ID	20.33	20.51	1.069	20.42	43.86	42.98	1.020	43.42	0.062	0.062	1.000	0.062

SD	19,94	20,32	1,019	20,13	42,16	43,77	1,038	42,97	0,050	0,077	1,540	0,064
E16												
SE	20,33	24,72	1,216	22,53	45,43	41,58	1,093	43,51	0,049	0,079	1,612	0,064
IE	21,48	22,21	1,034	21,85	42,58	43,43	1,020	43,01	0,052	0,077	1,481	0,065
ID	20,02	22,14	1,106	21,08	44,08	42,91	1,027	43,50	0,063	0,063	1,000	0,063
SD	20,91	21,04	1,006	20,98	42,30	42,69	1,009	42,50	0,054	0,070	1,296	0,062
E17												
SE	21,37	21,67	1,014	21,32	45,00	42,07	1,070	43,54	0,064	0,063	1,016	0,064
IE	22,26	22,03	1,010	22,15	42,21	43,81	1,038	43,01	0,040	0,092	2,300	0,066
ID	20,17	22,27	1,104	21,22	43,24	43,76	1,012	43,50	0,058	0,069	1,190	0,064
SD	22,32	20,50	1,099	21,51	43,23	42,81	1,010	43,02	0,059	0,069	1,169	0,064
E18												
SE	20,28	21,41	1,056	20,85	44,39	42,82	1,037	43,61	0,054	0,072	1,333	0,063
IE	22,26	22,75	1,022	22,51	43,23	42,90	1,008	43,07	0,058	0,068	1,172	0,063
ID	19,79	24,45	1,235	22,12	44,84	42,36	1,059	43,60	0,059	0,066	1,119	0,063
SD	22,39	21,12	1,060	21,76	42,97	43,20	1,005	43,09	0,056	0,071	1,268	0,064
E19												
SE	21,91	20,88	1,049	21,40	45,16	42,32	1,067	43,74	0,059	0,065	1,102	0,062
IE	21,31	21,69	1,018	21,50	43,33	43,06	1,006	43,20	0,048	0,081	1,688	0,065
ID	19,04	23,92	1,256	21,48	44,36	43,08	1,030	43,72	0,060	0,065	1,083	0,063
SD	21,72	21,05	1,032	21,39	43,44	42,92	1,012	43,18	0,061	0,067	1,098	0,064
E20												
SE	21,17	21,39	1,010	21,28	44,94	42,81	1,050	43,88	0,067	0,060	1,117	0,064
IE	21,84	22,28	1,020	22,06	43,53	43,03	1,012	43,28	0,055	0,072	1,309	0,064
ID	18,96	24,12	1,272	21,54	44,85	42,76	1,049	43,81	0,058	0,068	1,172	0,063
SD	18,79	23,86	1,270	21,33	42,54	43,94	1,033	43,24	0,057	0,069	1,211	0,063
	MEDIA D	1,081	20,84		MEDIA D	1,042	43,79		MEDIA D	1,308		0,063
	DESVIO D	0,061	0,96		DESVIO D	0,029	2,33		DESVIO D	0,265		0,001
	MEDIA E	1,083	21,20		MEDIA E	1,039	43,29		MEDIA E	1,317		0,063
	DESVIO E	0,073	0,79		DESVIO E	0,028	0,37		DESVIO E	0,274		0,001

	METAL 1 COLUNA DA DIREITA							METAL 1 COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die			R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die	
D01						0,063	E01						0,062
SE6C	0,052	0,075	1,442	0,064			ISE6C	0,050	0,075	1,500	0,063		
SE7C	0,048	0,077	1,604	0,063			ISE7C	0,047	0,076	1,617	0,062		
IE6C	0,052	0,074	1,423	0,063			IE6C	0,051	0,074	1,451	0,063		
IE7C	0,052	0,073	1,404	0,063			IE7C	0,050	0,072	1,440	0,061		
ID6C	0,054	0,074	1,370	0,064			ID6C	0,052	0,073	1,404	0,063		
ID7C	0,053	0,071	1,340	0,062			ID7C	0,051	0,071	1,392	0,061		
SD6C	0,052	0,073	1,404	0,063			SD6C	0,050	0,073	1,460	0,062		
SD7C	0,053	0,071	1,340	0,062			SD7C	0,051	0,071	1,392	0,061		
D02						0,063	E02						0,062
SE6C	0,051	0,074	1,451	0,063			ISE6C	0,049	0,074	1,510	0,062		
SE7C	0,048	0,078	1,625	0,063			ISE7C	0,047	0,077	1,638	0,062		
IE6C	0,051	0,075	1,471	0,063			IE6C	0,049	0,075	1,531	0,062		
IE7C	0,050	0,073	1,460	0,062			IE7C	0,048	0,074	1,542	0,061		
ID6C	0,053	0,074	1,396	0,064			ID6C	0,051	0,073	1,431	0,062		
ID7C	0,053	0,072	1,358	0,063			ID7C	0,051	0,072	1,412	0,062		
SD6C	0,053	0,073	1,377	0,063			SD6C	0,051	0,073	1,431	0,062		
SD7C	0,052	0,073	1,404	0,063			SD7C	0,050	0,073	1,460	0,062		
D03						0,063	E03						0,062
SE6C	0,050	0,075	1,500	0,063			ISE6C	0,049	0,075	1,531	0,062		
SE7C	0,049	0,077	1,571	0,063			ISE7C	0,047	0,077	1,638	0,062		
IE6C	0,051	0,075	1,471	0,063			IE6C	0,050	0,076	1,520	0,063		
IE7C	0,051	0,074	1,451	0,063			IE7C	0,050	0,074	1,480	0,062		
ID6C	0,052	0,074	1,423	0,063			ID6C	0,051	0,073	1,431	0,062		
ID7C	0,053	0,071	1,340	0,062			ID7C	0,051	0,071	1,392	0,061		
SD6C	0,053	0,073	1,377	0,063			SD6C	0,051	0,073	1,431	0,062		
SD7C	0,053	0,072	1,358	0,063			SD7C	0,052	0,072	1,385	0,062		
D04						0,063	E04						0,062
SE6C	0,050	0,076	1,520	0,063			ISE6C	0,048	0,076	1,583	0,062		
SE7C	0,052	0,075	1,442	0,064			ISE7C	0,049	0,074	1,510	0,062		
IE6C	0,051	0,074	1,451	0,063			IE6C	0,049	0,074	1,510	0,062		
IE7C	0,051	0,075	1,471	0,063			IE7C	0,049	0,075	1,531	0,062		
ID6C	0,053	0,074	1,396	0,064			ID6C	0,050	0,074	1,480	0,062		
ID7C	0,053	0,072	1,358	0,063			ID7C	0,051	0,071	1,392	0,061		
SD6C	0,054	0,071	1,315	0,063			SD6C	0,051	0,071	1,392	0,061		
SD7C	0,052	0,074	1,423	0,063			SD7C	0,050	0,074	1,480	0,062		
D05						0,063	E05						0,061
SE6C	0,052	0,074	1,423	0,063			ISE6C	0,049	0,073	1,490	0,061		
SE7C	0,050	0,078	1,560	0,064			ISE7C	0,048	0,077	1,604	0,063		
IE6C	0,052	0,074	1,423	0,063			IE6C	0,050	0,073	1,460	0,062		
IE7C	0,052	0,074	1,423	0,063			IE7C	0,049	0,073	1,490	0,061		
ID6C	0,053	0,073	1,377	0,063			ID6C	0,051	0,072	1,412	0,062		
ID7C	0,054	0,071	1,315	0,063			ID7C	0,051	0,071	1,392	0,061		
SD6C	0,052	0,074	1,423	0,063			SD6C	0,050	0,073	1,460	0,062		
SD7C	0,054	0,071	1,315	0,063			SD7C	0,051	0,070	1,373	0,061		
D06						0,062	E06						0,062
SE6C	0,050	0,075	1,500	0,063			ISE6C	0,048	0,076	1,583	0,062		
SE7C	0,049	0,075	1,531	0,062			ISE7C	0,047	0,076	1,617	0,062		
IE6C	0,051	0,072	1,412	0,062			IE6C	0,049	0,075	1,531	0,062		
IE7C	0,050	0,073	1,460	0,062			IE7C	0,049	0,074	1,510	0,062		
ID6C	0,052	0,071	1,365	0,062			ID6C	0,052	0,071	1,365	0,062		
ID7C	0,050	0,072	1,440	0,061			ID7C	0,052	0,070	1,346	0,061		
SD6C	0,050	0,075	1,500	0,063			SD6C	0,050	0,074	1,480	0,062		
SD7C	0,051	0,073	1,431	0,062			SD7C	0,052	0,070	1,346	0,061		
D07						0,062	E07						0,062
SE6C	0,051	0,074	1,451	0,063			ISE6C	0,051	0,073	1,431	0,062		
SE7C	0,050	0,073	1,460	0,062			ISE7C	0,046	0,079	1,717	0,063		

	METAL 1 COLUNA DA DIREITA						METAL 1 COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die		R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die	
IE6C	0,051	0,073	1,431	0,062		IIIE6C	0,049	0,075	1,531	0,062		
IE7C	0,049	0,074	1,510	0,062		IIIE7C	0,051	0,074	1,451	0,063		
ID6C	0,053	0,072	1,358	0,063		IID6C	0,052	0,074	1,423	0,063		
ID7C	0,051	0,073	1,431	0,062		IID7C	0,051	0,071	1,392	0,061		
SD6C	0,052	0,074	1,423	0,063		IISD6C	0,051	0,073	1,431	0,062		
SD7C	0,053	0,070	1,321	0,062		IISD7C	0,051	0,072	1,412	0,062		
D08					0,062 II E08						0,062	
SE6C	0,050	0,074	1,480	0,062		IISE6C	0,051	0,074	1,451	0,063		
SE7C	0,051	0,072	1,412	0,062		IISE7C	0,047	0,077	1,638	0,062		
IE6C	0,051	0,074	1,451	0,063		IIIE6C	0,050	0,074	1,480	0,062		
IE7C	0,050	0,076	1,520	0,063		IIIE7C	0,052	0,072	1,385	0,062		
ID6C	0,051	0,074	1,451	0,063		IID6C	0,051	0,077	1,510	0,064		
ID7C	0,053	0,073	1,377	0,063		IID7C	0,052	0,072	1,385	0,062		
SD6C	0,052	0,073	1,404	0,063		IISD6C	0,052	0,072	1,385	0,062		
SD7C	0,052	0,072	1,385	0,062		IISD7C	0,054	0,070	1,296	0,062		
D09					0,063 II E09						0,063	
SE6C	0,051	0,075	1,471	0,063		IISE6C	0,053	0,073	1,377	0,063		
SE7C	0,051	0,078	1,529	0,065		IISE7C	0,049	0,076	1,551	0,063		
IE6C	0,053	0,072	1,358	0,063		IIIE6C	0,051	0,075	1,471	0,063		
IE7C	0,051	0,075	1,471	0,063		IIIE7C	0,049	0,075	1,531	0,062		
ID6C	0,051	0,075	1,471	0,063		IID6C	0,053	0,073	1,377	0,063		
ID7C	0,052	0,074	1,423	0,063		IID7C	0,053	0,071	1,340	0,062		
SD6C	0,052	0,073	1,404	0,063		IISD6C	0,053	0,074	1,396	0,064		
SD7C	0,053	0,072	1,358	0,063		IISD7C	0,053	0,070	1,321	0,062		
D10					0,063 II E10						0,063	
SE6C	0,050	0,077	1,540	0,064		IISE6C	0,053	0,074	1,396	0,064		
SE7C	0,051	0,076	1,490	0,064		IISE7C	0,050	0,077	1,540	0,064		
IE6C	0,051	0,074	1,451	0,063		IIIE6C	0,051	0,076	1,490	0,064		
IE7C	0,051	0,074	1,451	0,063		IIIE7C	0,048	0,076	1,583	0,062		
ID6C	0,053	0,073	1,377	0,063		IID6C	0,054	0,072	1,333	0,063		
ID7C	0,051	0,074	1,451	0,063		IID7C	0,053	0,072	1,358	0,063		
SD6C	0,054	0,072	1,333	0,063		IISD6C	0,053	0,074	1,396	0,064		
SD7C	0,053	0,072	1,358	0,063		IISD7C	0,052	0,074	1,423	0,063		
D11					0,064 II E11						0,063	
SE6C	0,051	0,076	1,490	0,064		IISE6C	0,050	0,076	1,520	0,063		
SE7C	0,052	0,076	1,462	0,064		IISE7C	0,048	0,079	1,646	0,064		
IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064		IIIE6C	0,051	0,074	1,451	0,063		
IE7C	0,049	0,077	1,571	0,063		IIIE7C	0,050	0,076	1,520	0,063		
ID6C	0,053	0,073	1,415	0,064		IID6C	0,054	0,074	1,370	0,064		
ID7C	0,053	0,073	1,377	0,063		IID7C	0,052	0,073	1,404	0,063		
SD6C	0,053	0,075	1,415	0,064		IISD6C	0,053	0,074	1,396	0,064		
SD7C	0,054	0,071	1,315	0,063		IISD7C	0,053	0,074	1,396	0,064		
D12					0,064 II E12						0,063	
SE6C	0,055	0,075	1,364	0,065		IISE6C	0,053	0,074	1,396	0,064		
SE7C	0,052	0,074	1,423	0,063		IISE7C	0,048	0,079	1,646	0,064		
IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064		IIIE6C	0,052	0,074	1,423	0,063		
IE7C	0,052	0,075	1,442	0,064		IIIE7C	0,053	0,075	1,415	0,064		
ID6C	0,054	0,074	1,370	0,064		IID6C	0,053	0,074	1,396	0,064		
ID7C	0,052	0,073	1,404	0,063		IID7C	0,052	0,074	1,423	0,063		
SD6C	0,053	0,073	1,377	0,063		IISD6C	0,053	0,073	1,377	0,063		
SD7C	0,054	0,073	1,352	0,064		IISD7C	0,054	0,073	1,352	0,064		
D13					0,064 II E13						0,063	
SE6C	0,054	0,073	1,352	0,064		IISE6C	0,052	0,075	1,442	0,064		
SE7C	0,051	0,076	1,490	0,064		IISE7C	0,048	0,079	1,646	0,064		
IE6C	0,052	0,075	1,442	0,064		IIIE6C	0,052	0,075	1,442	0,064		
IE7C	0,050	0,078	1,560	0,064		IIIE7C	0,052	0,075	1,442	0,064		
ID6C	0,055	0,074	1,345	0,065		IID6C	0,054	0,074	1,370	0,064		

	METAL 1 COLUNA DA DIREITA						METAL 1 COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die		R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die	
ID7C	0,054	0,074	1,370	0,064			ID7C	0,053	0,073	1,377	0,063	
SD6C	0,055	0,073	1,327	0,064			SD6C	0,054	0,073	1,352	0,064	
SD7C	0,055	0,073	1,327	0,064			SD7C	0,054	0,072	1,333	0,063	
D14					0,063	E14						0,063
SE6C	0,051	0,076	1,490	0,064			SE6C	0,052	0,077	1,481	0,065	
SE7C	0,053	0,074	1,396	0,064			SE7C	0,048	0,079	1,646	0,064	
IE6C	0,051	0,076	1,490	0,064			IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064	
IE7C	0,051	0,075	1,471	0,063			IE7C	0,052	0,074	1,423	0,063	
ID6C	0,054	0,072	1,333	0,063			ID6C	0,055	0,071	1,291	0,063	
ID7C	0,052	0,075	1,442	0,064			ID7C	0,054	0,071	1,315	0,063	
SD6C	0,053	0,072	1,358	0,063			SD6C	0,053	0,072	1,358	0,063	
SD7C	0,054	0,071	1,315	0,063			SD7C	0,053	0,072	1,358	0,063	
D15					0,063	E15						0,063
SE6C	0,051	0,078	1,529	0,065			SE6C	0,052	0,075	1,442	0,064	
SE7C	0,051	0,076	1,490	0,064			SE7C	0,047	0,080	1,702	0,064	
IE6C	0,051	0,075	1,471	0,063			IE6C	0,052	0,075	1,442	0,064	
IE7C	0,051	0,077	1,510	0,064			IE7C	0,053	0,074	1,396	0,064	
ID6C	0,053	0,073	1,377	0,063			ID6C	0,054	0,073	1,352	0,064	
ID7C	0,052	0,074	1,423	0,063			ID7C	0,054	0,071	1,315	0,063	
SD6C	0,053	0,074	1,396	0,064			SD6C	0,055	0,071	1,291	0,063	
SD7C	0,053	0,072	1,358	0,063			SD7C	0,051	0,076	1,490	0,064	
D16					0,064	E16						0,064
SE6C	0,052	0,076	1,462	0,064			SE6C	0,052	0,074	1,423	0,063	
SE7C	0,052	0,073	1,404	0,063			SE7C	0,050	0,077	1,540	0,064	
IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064			IE6C	0,052	0,078	1,500	0,065	
IE7C	0,053	0,075	1,415	0,064			IE7C	0,053	0,076	1,434	0,065	
ID6C	0,055	0,072	1,309	0,064			ID6C	0,054	0,073	1,352	0,064	
ID7C	0,054	0,073	1,352	0,064			ID7C	0,053	0,074	1,396	0,064	
SD6C	0,055	0,074	1,345	0,065			SD6C	0,055	0,074	1,345	0,065	
SD7C	0,054	0,073	1,352	0,064			SD7C	0,055	0,071	1,291	0,063	
B17					0,064	E17						0,064
SE6C	0,053	0,077	1,453	0,065			SE6C	0,052	0,075	1,442	0,064	
SE7C	0,053	0,075	1,415	0,064			SE7C	0,051	0,077	1,510	0,064	
IE6C	0,052	0,074	1,423	0,063			IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064	
IE7C	0,053	0,075	1,415	0,064			IE7C	0,052	0,075	1,442	0,064	
ID6C	0,055	0,073	1,327	0,064			ID6C	0,056	0,077	1,375	0,067	
ID7C	0,053	0,073	1,377	0,063			ID7C	0,053	0,074	1,396	0,064	
SD6C	0,054	0,075	1,389	0,065			SD6C	0,057	0,071	1,246	0,064	
SD7C	0,055	0,071	1,291	0,063			SD7C	0,054	0,073	1,352	0,064	
D18					0,064	E18						0,064
SE6C	0,053	0,075	1,415	0,064			SE6C	0,052	0,074	1,423	0,063	
SE7C	0,053	0,075	1,415	0,064			SE7C	0,050	0,081	1,620	0,066	
IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064			IE6C	0,052	0,076	1,462	0,064	
IE7C	0,052	0,076	1,462	0,064			IE7C	0,053	0,075	1,415	0,064	
ID6C	0,057	0,075	1,316	0,066			ID6C	0,054	0,074	1,370	0,064	
ID7C	0,053	0,074	1,396	0,064			ID7C	0,055	0,075	1,364	0,065	
SD6C	0,055	0,074	1,345	0,065			SD6C	0,054	0,074	1,370	0,064	
SD7C	0,055	0,072	1,309	0,064			SD7C	0,054	0,072	1,333	0,063	
D19					0,064	E19						0,063
SE6C	0,054	0,075	1,389	0,065			SE6C	0,054	0,073	1,352	0,064	
SE7C	0,054	0,075	1,389	0,065			SE7C	0,049	0,078	1,592	0,064	
IE6C	0,054	0,076	1,407	0,065			IE6C	0,053	0,075	1,415	0,064	
IE7C	0,054	0,076	1,407	0,065			IE7C	0,051	0,076	1,490	0,064	
ID6C	0,054	0,073	1,352	0,064			ID6C	0,053	0,074	1,396	0,064	
ID7C	0,055	0,075	1,364	0,065			ID7C	0,053	0,072	1,358	0,063	
SD6C	0,056	0,072	1,286	0,064			SD6C	0,055	0,072	1,309	0,064	
SD7C	0,057	0,071	1,246	0,064			SD7C	0,052	0,074	1,423	0,063	

	METAL 1 COLUNA DA DIREITA							METAL 1 COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die			R1	R2	R1/R2	RS	Iavg/die	
D20					0,064	E20						0,064	
SE6C	0,054	0,075	1,389	0,065		SE6C	0,053	0,075	1,415	0,064			
SE7C	0,053	0,075	1,415	0,064		SE7C	0,049	0,079	1,612	0,064			
IE6C	0,054	0,075	1,389	0,065		IE6C	0,053	0,074	1,396	0,064			
IE7C	0,054	0,076	1,407	0,065		IE7C	0,051	0,076	1,490	0,064			
ID6C	0,055	0,074	1,345	0,065		ID6C	0,054	0,074	1,370	0,064			
ID7C	0,055	0,074	1,345	0,065		ID7C	0,054	0,073	1,352	0,064			
SD6C	0,056	0,072	1,286	0,064		SD6C	0,053	0,074	1,396	0,064			
SD7C	0,056	0,072	1,286	0,064		SD7C	0,053	0,073	1,377	0,063			
MEDIA	1,413	0,063	0,063			MEDIA	1,428	0,063	0,063				
SIGMA	0,067	0,001	0,001			SIGMA	0,081	0,001	0,001				

B01	POLY COLUNA DA DIREITA						POLY COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	Avg/DIE	E01	R1	R2	R1/R2	RS	Avg/DIE	20.660
SE1A	18,211	21,539	1,183	19,875	20,654	ISE1A	18,088	21,790	1,205	19,939		
SE2A	18,222	22,739	1,248	20,481		ISE2A	18,123	22,691	1,252	20,407		
SE4A	19,949	22,545	1,130	21,247		ISE4A	19,836	25,509	1,286	22,673		
SE6A	16,816	24,035	1,429	20,426		ISE6A	16,722	23,996	1,435	20,359		
SE5A	20,147	23,598	1,171	21,873		ISE5A	20,052	23,526	1,173	21,789		
IE1A	19,636	23,088	1,176	21,362		IEE1A	19,519	23,023	1,180	21,271		
IE2A	18,343	23,558	1,284	20,951		IEE2A	18,237	23,506	1,289	20,872		
IE4A	18,925	22,590	1,194	20,758		IEE4A	18,810	22,539	1,198	20,675		
IE6A	19,547	20,999	1,074	20,273		IEE6A	19,446	20,945	1,077	20,196		
IE5A	19,043	21,389	1,123	20,216		IEE5A	18,916	21,334	1,128	20,125		
ID1A	21,100	19,849	1,063	20,475		IDI1A	21,003	19,778	1,062	20,391		
ID2A	17,374	24,540	1,412	20,937		IDD2A	17,269	24,493	1,418	20,881		
ID4A	19,027	21,853	1,149	20,440		IDD4A	18,925	21,801	1,152	20,363		
ID6A	18,825	22,412	1,191	20,619		IDD6A	18,728	22,377	1,195	20,533		
ID5A	18,978	24,775	1,305	21,877		IDD5A	18,882	24,723	1,309	21,803		
SD1A	18,480	22,159	1,199	20,320		ISD1A	18,369	22,101	1,203	20,235		
SD2A	18,204	21,459	1,179	19,832		ISD2A	18,109	21,417	1,183	19,763		
SD4A	17,527	22,523	1,285	20,025		ISD4A	17,419	22,485	1,291	19,932		
SD6A	17,333	23,529	1,357	20,431		ISD6A	17,246	23,491	1,362	20,369		
SD5A	20,340	20,969	1,031	20,635		ISD5A	20,249	20,921	1,033	20,585		
B02	21,120 E02						21,041					
	SE1A	22,074	21,667	1,019	21,871	ISE1A	21,980	21,623	1,017	21,802		
SE2A	16,876	22,840	1,353	19,858		ISE2A	16,384	22,789	1,391	19,587		
SE4A	21,975	20,754	1,059	21,385		ISE4A	21,885	20,700	1,057	21,293		
SE6A	18,352	23,895	1,302	21,124		ISE6A	18,326	23,842	1,301	21,064		
SE5A	18,450	25,228	1,367	21,939		ISE5A	18,351	25,175	1,372	21,743		
IE1A	20,559	24,891	1,211	22,725		IEE1A	20,449	24,845	1,215	22,647		
IE2A	18,198	22,636	1,244	20,417		IEE2A	18,114	22,584	1,247	20,349		
IE4A	18,976	23,677	1,248	21,327		IEE4A	18,778	23,565	1,255	21,172		
IE6A	18,974	21,142	1,114	20,058		IEE6A	18,888	21,088	1,116	19,988		
IE5A	19,901	24,511	1,238	22,156		IEE5A	19,717	24,465	1,241	22,091		
ID1A	21,039	22,892	1,088	21,966		IDI1A	20,991	22,847	1,088	21,919		
ID2A	19,073	24,038	1,260	21,556		IDD2A	18,993	23,990	1,263	21,492		
ID4A	19,399	23,804	1,227	21,602		IDD4A	19,310	23,752	1,230	21,531		
ID6A	17,661	22,003	1,246	19,832		IDD6A	17,580	21,950	1,249	19,765		
ID5A	18,476	23,838	1,290	21,157		IDD5A	18,392	23,782	1,293	21,087		
SD1A	18,734	20,757	1,108	19,746		ISD1A	18,644	20,697	1,110	19,671		
SD2A	18,771	23,628	1,259	21,200		ISD2A	18,756	23,590	1,258	21,173		
SD4A	19,613	19,992	1,019	19,803		ISD4A	19,524	19,941	1,021	19,733		
SD6A	18,177	22,504	1,238	20,341		ISD6A	18,108	22,456	1,240	20,282		
SD5A	19,856	25,065	1,262	22,461		ISD5A	19,767	25,025	1,266	22,396		
B03	21,165 E03						21,111					
	SE1A	19,846	23,943	1,206	21,893	ISE1A	19,758	23,885	1,209	21,822		
SE2A	18,148	24,500	1,350	21,324		ISE2A	18,075	24,453	1,353	21,244		
SE4A	20,600	22,022	1,069	21,311		ISE4A	20,521	21,973	1,071	21,247		
SE6A	19,113	23,276	1,218	21,195		ISE6A	19,065	23,228	1,218	21,147		
SE5A	20,864	22,557	1,081	21,711		ISE5A	20,790	22,501	1,082	21,646		
IE1A	20,267	24,166	1,192	22,217		IEE1A	20,194	24,118	1,194	22,156		
IE2A	19,118	22,165	1,159	20,642		IEE2A	19,055	22,118	1,161	20,587		
IE4A	19,342	20,962	1,084	20,152		IEE4A	19,264	20,906	1,085	20,095		
IE6A	19,187	22,562	1,176	20,875		IEE6A	19,107	22,511	1,178	20,809		
IE5A	20,587	20,764	1,009	20,676		IEE5A	20,514	20,712	1,010	20,613		
ID1A	20,651	22,048	1,068	21,350		IDI1A	20,633	22,000	1,066	21,317		
ID2A	18,787	22,663	1,206	20,725		IDD2A	18,717	22,609	1,208	20,663		
ID4A	19,514	22,391	1,147	20,953		IDD4A	19,448	22,337	1,149	20,893		
ID6A	20,099	21,892	1,089	20,996		IDD6A	20,035	21,828	1,089	20,932		

		POLY	COLUNA DA DIREITA			POLY	COLUNA DA ESQUERDA				
	R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE		R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE
B01					20,654	E01					20,660
SE1A	18,211	21,539	1,183	19,875		ISE1A	18,068	21,790	1,205	19,939	
SE2A	18,222	22,739	1,248	20,481		ISE2A	18,123	22,691	1,252	20,407	
SE4A	19,949	22,545	1,130	21,247		ISE4A	19,836	25,509	1,286	22,673	
SE6A	16,816	24,035	1,429	20,426		ISE6A	16,722	23,996	1,435	20,359	
SE5A	20,147	23,598	1,171	21,873		ISE5A	20,052	23,524	1,173	21,789	
IE1A	19,636	23,068	1,176	21,342		IIE1A	19,519	23,023	1,180	21,271	
IE2A	18,343	23,558	1,284	20,951		IIE2A	18,237	23,506	1,289	20,872	
IE4A	18,925	22,590	1,194	20,758		IIE4A	18,810	22,539	1,198	20,675	
IE6A	19,547	20,999	1,074	20,273		IIE6A	19,446	20,945	1,077	20,196	
IE5A	19,043	21,389	1,123	20,216		IIE5A	19,916	21,334	1,128	20,125	
ID1A	21,100	19,849	1,063	20,475		IID1A	21,003	19,778	1,062	20,391	
ID2A	17,374	24,540	1,412	20,957		IID2A	17,249	24,493	1,418	20,881	
ID4A	19,027	21,853	1,149	20,440		IID4A	18,925	21,801	1,152	20,363	
J2A	18,825	22,412	1,191	20,619		IID6A	18,728	22,377	1,195	20,553	
ID5A	18,978	24,775	1,305	21,877		IID5A	18,882	24,723	1,309	21,803	
SD1A	18,480	22,159	1,199	20,320		ISD1A	18,369	22,101	1,203	20,235	
SD2A	18,204	21,459	1,179	19,832		ISD2A	18,109	21,417	1,183	19,763	
SD4A	17,327	22,523	1,285	20,025		ISD4A	17,419	22,485	1,291	19,952	
SD6A	17,333	23,529	1,357	20,431		ISD6A	17,246	23,491	1,362	20,369	
SD5A	20,340	20,969	1,031	20,635		ISD5A	20,249	20,921	1,033	20,585	
B02					21,120	E02					21,041
SE1A	22,074	21,667	1,019	21,871		ISE1A	21,980	21,623	1,017	21,802	
SE2A	16,876	22,840	1,353	19,858		ISE2A	16,384	22,789	1,391	19,587	
SE4A	21,975	20,754	1,059	21,365		ISE4A	21,885	20,700	1,057	21,293	
SE6A	18,352	23,895	1,302	21,124		ISE6A	18,326	23,842	1,301	21,084	
SE5A	18,450	25,228	1,367	21,839		ISE5A	18,351	25,175	1,372	21,763	
IE1A	20,559	24,891	1,211	22,725		IIE1A	20,449	24,845	1,215	22,647	
IE2A	18,198	22,436	1,244	20,417		IIE2A	18,114	22,584	1,247	20,349	
IE4A	18,976	23,677	1,248	21,327		IIE4A	18,778	23,565	1,253	21,172	
IE6A	18,974	21,142	1,114	20,058		IIE6A	18,888	21,068	1,116	19,988	
IE5A	19,801	24,511	1,238	22,154		IIE5A	19,717	24,465	1,241	22,091	
ID1A	21,039	22,892	1,088	21,966		IID1A	20,991	22,847	1,088	21,919	
J2A	19,073	24,038	1,260	21,556		IID2A	18,993	23,990	1,263	21,492	
ID4A	19,399	23,804	1,227	21,602		IID4A	19,310	23,732	1,230	21,531	
ID6A	17,661	22,003	1,244	19,832		IID6A	17,580	21,950	1,249	19,765	
ID5A	18,476	23,838	1,290	21,157		IID5A	18,392	23,782	1,293	21,087	
SD1A	18,734	20,757	1,108	19,746		ISD1A	18,644	20,697	1,110	19,671	
SD2A	18,771	23,628	1,259	21,200		ISD2A	18,756	23,590	1,258	21,173	
SD4A	19,613	19,992	1,019	19,803		ISD4A	19,524	19,941	1,021	19,733	
SD6A	18,177	22,564	1,238	20,341		ISD6A	18,108	22,456	1,240	20,282	
SD5A	19,856	25,065	1,262	22,461		ISD5A	19,767	25,025	1,266	22,396	
B03					21,165	E03					21,111
SE1A	19,846	23,943	1,206	21,895		ISE1A	19,758	23,885	1,209	21,822	
SE2A	18,148	24,500	1,350	21,324		ISE2A	18,075	24,453	1,353	21,264	
SE4A	20,600	22,022	1,069	21,311		ISE4A	20,521	21,973	1,071	21,247	
SE6A	19,113	23,276	1,218	21,195		ISE6A	19,065	23,228	1,218	21,147	
SE5A	20,864	22,557	1,081	21,711		ISE5A	20,790	22,501	1,082	21,646	
IE1A	20,247	24,166	1,192	22,217		IIE1A	20,194	24,118	1,194	22,156	
IE2A	19,118	22,165	1,159	20,642		IIE2A	19,055	22,118	1,161	20,587	
IE4A	19,342	20,962	1,084	20,152		IIE4A	19,264	20,906	1,085	20,085	
IE6A	19,187	22,562	1,176	20,875		IIE6A	19,107	22,511	1,178	20,809	
IE5A	20,587	20,764	1,009	20,476		IIE5A	20,514	20,712	1,010	20,613	
ID1A	20,651	22,048	1,068	21,350		IID1A	20,633	22,000	1,068	21,317	
ID2A	18,787	22,663	1,206	20,725		IID2A	18,717	22,609	1,208	20,663	
ID4A	19,514	22,391	1,147	20,953		IID4A	19,448	22,337	1,149	20,893	
ID6A	20,099	21,892	1,089	20,996		IID6A	20,035	21,828	1,089	20,932	

	POLY	COLUMNA DA DIREITA	R1	R2	R1/R2	RS	Avg/DIE		POLY	COLUMNA DA ESQUERDA	R1	R2	R1/R2	RS	Avg/DIE	
ID5A	22,396	20,877	1,082	21,737				IID5A	22,576	20,865	1,082	21,721				
SD1A	20,226	23,770	1,175	21,998				ISD1A	20,174	23,742	1,177	21,958				
SD2A	17,651	22,989	1,302	20,320				ISD2A	17,582	22,940	1,305	20,261				
SD4A	21,437	19,912	1,087	20,775				ISD4A	21,559	19,863	1,085	20,711				
SD6A	18,390	23,946	1,288	21,268				ISD6A	18,624	23,898	1,283	21,261				
SD5A	20,706	21,672	1,047	21,189				ISD5A	20,632	21,621	1,048	21,127				
D04							21,503	E04								21,360
SE1A	19,421	22,342	1,150	20,882				ISE1A	19,270	22,193	1,152	20,732				
SE2A	18,860	24,270	1,287	21,565				ISE2A	18,563	24,128	1,300	21,346				
SE4A	20,050	24,494	1,222	22,272				ISE4A	19,887	24,378	1,226	22,133				
SE6A	16,349	22,366	1,352	19,458				ISE6A	16,413	22,220	1,354	19,317				
SE5A	18,623	23,667	1,271	21,145				ISE5A	18,476	23,116	1,251	20,796				
IE1A	20,332	25,035	1,231	22,684				IIE1A	20,172	24,900	1,234	22,536				
IE2A	19,416	21,428	1,104	20,422				IIE2A	19,330	21,285	1,101	20,308				
IE4A	19,583	23,366	1,193	21,475				IIE4A	19,483	23,233	1,192	21,358				
IE6A	19,781	23,203	1,173	21,492				IIE6A	19,664	23,060	1,173	21,362				
IE5A	21,424	23,336	1,089	22,380				IIE5A	21,291	23,190	1,089	22,241				
ID1A	20,019	24,005	1,199	22,012				IID1A	19,971	23,078	1,196	21,925				
ID2A	18,324	23,875	1,303	21,100				IID2A	18,206	23,732	1,304	20,969				
ID4A	19,882	24,087	1,211	21,985				IID4A	19,746	23,940	1,212	21,843				
ID6A	18,995	22,430	1,181	20,713				IID6A	18,880	22,301	1,181	20,591				
ID5A	18,458	23,408	1,268	20,933				IID5A	18,356	23,319	1,270	20,838				
SD1A	21,601	21,950	1,016	21,776				ISD1A	21,476	21,810	1,016	21,643				
SD2A	19,245	23,481	1,220	21,363				ISD2A	19,129	23,360	1,221	21,245				
SD4A	21,827	23,312	1,068	22,570				ISD4A	21,691	23,186	1,069	22,439				
SD6A	17,497	24,840	1,420	21,169				ISD6A	17,387	24,717	1,422	21,052				
SD5A	21,257	24,091	1,133	22,674				ISD5A	21,116	23,948	1,134	22,532				
D05					21,939	E05										21,814
SE1A	21,450	23,212	1,082	22,331				ISE1A	21,344	23,036	1,079	22,190				
SE2A	19,685	23,198	1,178	21,442				ISE2A	19,570	23,043	1,177	21,307				
SE4A	20,070	25,046	1,248	22,558				ISE4A	19,960	24,866	1,246	22,413				
SE6A	18,143	23,988	1,322	21,066				ISE6A	18,029	23,835	1,322	20,932				
SE5A	20,946	23,265	1,111	22,106				ISE5A	20,848	23,104	1,108	21,976				
IE1A	20,535	21,416	1,043	20,976				IIE1A	20,422	21,250	1,041	20,836				
IE2A	20,054	22,466	1,120	21,260				IIE2A	19,965	22,318	1,118	21,142				
IE4A	19,734	23,720	1,303	22,727				IIE4A	19,631	25,565	1,302	22,598				
IE6A	19,370	23,979	1,238	21,675				IIE6A	19,317	23,847	1,235	21,582				
IE5A	19,216	24,875	1,294	22,046				IIE5A	19,120	24,740	1,294	21,930				
ID1A	22,211	24,652	1,110	23,432				IID1A	22,086	24,511	1,110	23,299				
ID2A	19,768	22,654	1,146	21,211				IID2A	19,676	22,520	1,145	21,098				
ID4A	20,317	22,013	1,083	21,165				IID4A	20,188	21,890	1,084	21,039				
ID6A	20,219	23,818	1,178	22,019				IID6A	20,127	23,692	1,177	21,910				
ID5A	20,177	25,077	1,243	22,427				IID5A	20,074	24,941	1,242	22,508				
SD1A	22,747	22,861	1,005	22,804				ISD1A	22,637	22,695	1,003	22,666				
SD2A	18,811	24,136	1,283	21,474				ISD2A	18,707	23,999	1,283	21,353				
SD4A	22,949	22,969	1,001	22,959				ISD4A	22,867	22,829	1,002	22,848				
SD6A	18,753	23,049	1,229	20,901				ISD6A	18,653	22,906	1,228	20,786				
SD5A	19,705	24,319	1,234	22,012				ISD5A	19,585	24,182	1,235	21,884				
D06					21,337	E06										22,020
SE1A	20,679	23,952	1,158	22,316				ISE1A	22,346	25,109	1,124	23,728				
SE2A	18,357	24,620	1,341	21,489				ISE2A	16,809	24,767	1,473	20,788				
SE4A	21,815	20,548	1,061	21,192				ISE4A	19,310	25,248	1,309	22,289				
SE6A	18,544	24,129	1,301	21,337				ISE6A	17,969	25,961	1,445	21,965				
SE5A	22,293	22,489	1,009	22,391				ISE5A	19,615	24,436	1,246	22,026				
IE1A	21,151	22,795	1,078	21,973				IIE1A	21,268	24,943	1,173	23,106				
IE2A	19,153	22,017	1,150	20,585				IIE2A	18,320	23,586	1,287	20,953				
IE4A	20,238	23,980	1,185	22,109				IIE4A	21,626	24,233	1,121	22,930				

	POLY COLUNA DA DIREITA							POLY COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE			R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE	
IE6A	18,593	24,116	1,297	21,355		IIE6A	19,469	22,748	1,168	21,109			
IE5A	20,676	20,029	1,032	20,353		IIE5A	18,623	24,804	1,332	21,714			
ID1A	20,492	21,623	1,055	21,058		IID1A	21,181	22,767	1,075	21,974			
ID2A	19,998	22,536	1,127	21,267		IID2A	18,829	23,301	1,238	21,065			
ID4A	19,435	23,332	1,201	21,384		IID4A	20,020	25,509	1,274	22,765			
ID6A	19,474	23,148	1,189	21,311		IID6A	20,114	23,529	1,170	21,822			
ID5A	21,287	24,037	1,129	22,462		IID5A	19,825	24,484	1,235	22,155			
SD1A	19,679	22,209	1,129	20,944		ISD1A	21,206	23,191	1,094	22,199			
SD2A	17,925	22,937	1,280	20,431		ISD2A	19,655	22,803	1,160	21,229			
SD4A	20,076	22,174	1,103	21,135		ISD4A	22,079	21,720	1,017	21,900			
SD6A	18,776	22,893	1,219	20,835		ISD6A	19,259	24,560	1,275	21,910			
SD5A	20,600	20,650	1,002	20,625		ISD5A	20,778	24,764	1,192	22,771			
D07					21,680	E07						21,967	
SE1A	22,514	23,828	1,058	23,171		ISE1A	20,821	24,342	1,170	22,592			
2A	19,023	23,854	1,254	21,439		ISE2A	20,290	22,679	1,118	21,485			
SE4A	20,556	23,760	1,156	22,158		ISE4A	19,331	24,141	1,249	21,736			
SE6A	18,468	23,139	1,253	20,804		ISE6A	19,301	23,549	1,220	21,425			
SE5A	19,257	23,919	1,242	21,588		ISE5A	18,766	26,693	1,422	22,730			
IE1A	21,343	22,718	1,064	22,031		IIE1A	20,936	23,088	1,103	22,012			
IE2A	18,724	23,941	1,279	21,333		IIE2A	18,612	24,059	1,293	21,336			
IE4A	19,335	25,996	1,345	22,666		IIE4A	21,126	25,122	1,189	23,124			
IE6A	19,330	24,498	1,267	21,914		IIE6A	18,976	23,916	1,260	21,446			
IE5A	19,836	22,326	1,126	21,081		IIE5A	22,933	23,751	1,036	23,342			
ID1A	19,884	22,452	1,139	21,268		IID1A	19,228	24,226	1,266	21,727			
ID2A	18,425	23,921	1,298	21,173		IID2A	18,950	23,372	1,233	21,161			
ID4A	19,634	24,784	1,282	22,209		IID4A	19,472	23,045	1,183	21,259			
ID6A	18,919	22,678	1,199	20,799		IID6A	19,344	22,820	1,180	21,082			
ID5A	22,048	21,956	1,004	22,002		IID5A	19,989	24,360	1,219	22,175			
SD1A	19,461	22,096	1,135	20,779		ISD1A	21,114	23,677	1,121	22,394			
SD2A	18,813	24,719	1,314	21,766		ISD2A	19,232	23,471	1,220	21,352			
SD4A	20,621	22,832	1,107	21,727		ISD4A	21,083	24,926	1,182	23,005			
SD6A	18,200	24,348	1,338	21,274		ISD6A	19,291	23,931	1,241	21,611			
SD5A	17,985	26,859	1,493	22,422		ISD5A	21,484	23,221	1,081	22,353			
D08					21,942	E08						22,247	
SE1A	22,135	23,014	1,040	22,575		ISE1A	21,162	26,039	1,230	23,601			
SE2A	19,785	24,594	1,243	22,190		ISE2A	18,939	24,276	1,282	21,608			
SE4A	20,345	22,829	1,122	21,587		ISE4A	18,473	25,560	1,384	22,017			
SE6A	20,229	24,030	1,188	22,130		ISE6A	19,514	23,732	1,216	21,623			
SE5A	21,166	23,236	1,098	22,201		ISE5A	19,297	25,696	1,332	22,497			
IE1A	18,712	24,671	1,318	21,692		IIE1A	19,376	25,604	1,321	22,490			
IE2A	18,889	23,003	1,218	20,946		IIE2A	18,996	24,821	1,307	21,909			
IE4A	19,698	24,696	1,254	22,197		IIE4A	21,058	24,228	1,151	22,643			
IE6A	19,433	22,806	1,174	21,120		IIE6A	19,179	24,910	1,299	22,045			
IE5A	20,248	24,388	1,204	22,318		IIE5A	20,070	26,323	1,312	23,197			
ID1A	24,829	21,328	1,164	23,079		IID1A	19,398	24,285	1,252	21,842			
ID2A	18,367	24,535	1,336	21,451		IID2A	18,941	24,546	1,298	21,744			
ID4A	18,887	21,848	1,157	20,368		IID4A	20,857	24,822	1,190	22,840			
ID6A	18,594	23,095	1,242	20,845		IID6A	19,735	23,496	1,191	21,616			
ID5A	18,809	25,378	1,349	22,094		IID5A	18,180	23,831	1,311	21,006			
SD1A	19,777	26,430	1,336	23,104		ISD1A	22,133	24,841	1,122	23,487			
SD2A	19,870	23,706	1,193	21,788		ISD2A	18,699	23,494	1,256	21,097			
SD4A	21,678	23,316	1,076	22,497		ISD4A	23,833	22,221	1,073	23,027			
SD6A	19,830	23,986	1,210	21,908		ISD6A	19,249	24,823	1,290	22,036			
SD5A	22,339	23,183	1,038	22,761		ISD5A	21,187	24,064	1,136	22,626			
D09					22,298	E09						22,385	
SE1A	22,064	23,732	1,076	22,898		ISE1A	21,369	25,806	1,208	23,588			
SE2A	18,846	24,223	1,285	21,535		ISE2A	19,799	24,202	1,222	22,001			

	POLY COLUNA DA DIREITA							POLY COLUNA DA ESQUERDA						
	R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE			R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE		
SE4A	21,544	23,935	1,111	22,740	1		ISE4A	20,052	22,882	1,141	21,467	1		
SE6A	19,679	24,459	1,243	22,069	1		ISE6A	19,309	23,331	1,312	22,320	1		
SE5A	21,226	24,578	1,158	22,902	1		ISE5A	22,079	24,790	1,123	23,435	1		
IE1A	22,663	23,317	1,029	22,990	1		IIE1A	23,046	23,206	1,007	23,126	1		
IE2A	19,056	24,576	1,290	21,816	1		IIE2A	18,802	23,172	1,232	20,987	1		
IE4A	20,128	24,329	1,209	22,229	1		IIE4A	22,385	23,599	1,054	22,992	1		
IE6A	19,688	24,094	1,224	21,891	1		IIE6A	21,255	23,696	1,115	22,476	1		
IESA	21,824	23,969	1,098	22,897	1		IIESA	20,476	25,703	1,243	23,190	1		
ID1A	22,790	23,034	1,011	22,912	1		IID1A	20,673	23,607	1,142	22,140	1		
ID2A	19,385	24,776	1,278	22,081	1		IID2A	19,137	24,902	1,301	22,020	1		
ID4A	19,825	24,990	1,261	22,408	1		IID4A	19,741	21,159	1,072	20,450	1		
ID6A	19,480	23,774	1,220	21,627	1		IID6A	18,977	23,683	1,248	21,330	1		
ID5A	19,828	25,243	1,273	22,536	1		IID5A	20,724	25,493	1,230	23,109	1		
SD1A	21,536	24,605	1,143	23,071	1		ISD1A	21,433	25,478	1,189	23,456	1		
SD2A	19,397	22,234	1,146	20,816	1		ISD2A	20,236	24,754	1,223	22,495	1		
SD4A	21,950	22,994	1,048	22,472	1		ISD4A	21,143	23,107	1,093	22,125	1		
SD6A	19,888	23,601	1,187	21,745	1		ISD6A	18,440	25,600	1,388	22,020	1		
SD5A	19,989	24,670	1,234	22,330	1		ISD5A	21,283	24,659	1,159	22,971	1		
D10							21,921	E10						22,439
SE1A	21,160	25,559	1,208	23,360	1		ISE1A	20,223	22,974	1,136	21,399	1		
SE2A	19,371	24,190	1,249	21,781	1		ISE2A	18,666	25,095	1,344	21,681	1		
SE4A	20,976	24,270	1,157	22,623	1		ISE4A	22,020	23,040	1,046	22,530	1		
SE6A	20,688	23,762	1,149	22,225	1		ISE6A	18,169	25,868	1,424	22,019	1		
SE5A	20,913	23,080	1,104	21,997	1		ISE5A	22,121	25,207	1,140	23,664	1		
IE1A	21,272	25,222	1,186	23,247	1		IIE1A	19,505	25,194	1,292	22,350	1		
IE2A	19,054	24,137	1,267	21,596	1		IIE2A	20,475	24,796	1,211	22,636	1		
IE4A	19,925	22,945	1,152	21,435	1		IIE4A	23,145	22,859	1,013	23,002	1		
IE6A	19,671	23,944	1,217	21,808	1		IIE6A	18,335	24,297	1,325	21,316	1		
IE5A	20,969	23,987	1,144	22,478	1		IIE5A	20,968	24,516	1,169	22,742	1		
ID1A	21,611	19,726	1,096	20,669	1		IID1A	20,859	26,613	1,276	23,736	1		
ID2A	19,733	23,790	1,206	21,762	1		IID2A	19,551	24,015	1,228	21,783	1		
ID4A	19,952	24,570	1,231	22,261	1		IID4A	20,161	26,935	1,336	23,548	1		
ID6A	19,415	23,443	1,207	21,429	1		IID6A	20,589	23,615	1,147	22,102	1		
IS5A	19,398	20,369	1,050	19,884	1		IID5A	20,244	23,744	1,173	21,994	1		
SD1A	20,219	22,891	1,132	21,555	1		ISD1A	21,231	26,106	1,230	23,669	1		
SD2A	19,650	22,665	1,153	21,158	1		ISD2A	20,377	24,696	1,212	22,537	1		
SD4A	21,467	23,508	1,095	22,498	1		ISD4A	20,840	22,645	1,086	21,753	1		
SD6A	20,604	23,165	1,124	21,885	1		ISD6A	19,295	24,427	1,266	21,861	1		
SD5A	21,811	23,754	1,089	22,783	1		ISD5A	20,287	23,842	1,175	22,065	1		
D11							22,092	E11						22,418
SE1A	20,227	25,780	1,275	23,004	1		ISE1A	20,883	25,120	1,203	23,002	1		
SE2A	20,031	24,083	1,202	22,057	1		ISE2A	20,086	24,999	1,245	22,543	1		
SE4A	20,188	22,350	1,107	21,269	1		ISE4A	21,922	23,467	1,070	22,695	1		
SE6A	20,039	23,958	1,196	21,999	1		ISE6A	19,412	24,818	1,278	22,115	1		
SE5A	21,872	22,793	1,042	22,333	1		ISE5A	18,158	27,527	1,516	22,842	1		
IE1A	21,559	25,548	1,185	23,554	1		IIE1A	22,152	25,102	1,133	23,627	1		
IE2A	17,752	22,423	1,263	20,088	1		IIE2A	18,730	26,105	1,394	22,418	1		
IE4A	21,088	21,405	1,015	21,247	1		IIE4A	18,800	23,552	1,253	21,176	1		
IE6A	20,506	24,348	1,187	22,427	1		IIE6A	20,073	24,556	1,223	22,315	1		
IESA	21,092	24,038	1,140	22,565	1		IIESA	23,495	22,862	1,028	23,179	1		
ID1A	21,546	25,171	1,168	23,359	1		IID1A	22,657	22,301	1,016	22,479	1		
ID2A	20,462	22,832	1,116	21,647	1		IID2A	19,491	24,623	1,250	22,157	1		
D4A	18,692	23,993	1,284	21,343	1		IID4A	22,039	23,639	1,073	22,839	1		
ID6A	20,150	23,195	1,151	21,673	1		IID6A	19,726	24,184	1,226	21,955	1		
ID5A	18,709	25,089	1,341	21,899	1		IID5A	18,494	24,251	1,311	21,373	1		
SD1A	20,616	23,534	1,142	22,075	1		ISD1A	21,602	25,701	1,190	23,652	1		
SD2A	18,299	24,816	1,356	21,558	1		ISD2A	18,194	24,311	1,336	21,253	1		

	POLY COLUNA DA DIREITA						POLY COLUNA DA ESGUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	IAVG/DIE		R1	R2	R1/R2	RS	IAVG/DIE	
SD4A	20,708	25,500	1,231	23,104		ISD4A	21,210	25,065	1,182	23,138		
SD6A	18,046	24,398	1,352	21,222		ISD6A	19,986	23,122	1,157	21,554		
SD5A	21,767	25,073	1,152	23,420		ISD5A	21,261	22,839	1,074	22,050		
D12				21,993	E12						22,403	
SE1A	22,150	22,904	1,034	22,527		ISE1A	20,897	26,074	1,248	23,486		
SE2A	19,835	23,357	1,178	21,596		ISE2A	19,042	23,646	1,242	21,344		
SE4A	20,762	23,038	1,110	21,900		ISE4A	23,579	23,613	1,001	23,596		
SE6A	19,315	23,850	1,235	21,583		ISE6A	19,030	24,310	1,277	21,670		
SE5A	19,898	23,494	1,181	21,696		ISE5A	21,208	23,360	1,101	22,284		
IE1A	21,590	22,895	1,060	22,243		IEE1A	24,375	24,343	1,010	24,459		
IE2A	19,019	23,224	1,221	21,122		IEE2A	20,391	24,472	1,200	22,432		
IE4A	21,456	23,908	1,114	22,682		IEE4A	23,197	22,402	1,035	22,800		
IE6A	19,831	23,954	1,208	21,893		IEE6A	20,467	24,390	1,192	22,429		
IESA	19,524	24,239	1,241	21,682		IEE5A	21,579	22,032	1,021	21,806		
I8	21,153	24,557	1,161	22,855		IID1A	22,365	24,261	1,085	23,313		
ID2A	20,569	23,015	1,119	21,792		IID2A	19,908	23,894	1,200	21,901		
ID4A	21,520	23,003	1,069	22,282		IID4A	20,277	23,001	1,134	21,639		
ID6A	20,024	23,064	1,152	21,544		IID6A	19,097	25,095	1,314	22,096		
ID5A	20,805	21,852	1,050	21,329		IID5A	22,907	22,603	1,013	22,755		
SD1A	23,395	22,486	1,040	22,941		ISD1A	19,984	27,858	1,394	23,921		
SD2A	19,583	23,691	1,210	21,637		ISD2A	18,395	25,179	1,369	21,787		
SD4A	21,819	23,016	1,055	22,418		ISD4A	20,036	20,916	1,044	20,476		
SD6A	19,230	23,394	1,217	21,312		ISD6A	18,705	24,354	1,302	21,530		
SD5A	19,372	25,932	1,339	22,652		ISD5A	23,085	21,605	1,069	22,345		
D13			21,857	E13							22,324	
SE1A	22,517	23,940	1,043	23,229		ISE1A	21,276	23,896	1,123	22,586		
SE2A	19,750	23,286	1,175	21,478		ISE2A	19,486	24,516	1,258	22,001		
SE4A	21,865	22,321	1,021	22,093		ISE4A	19,218	23,751	1,236	21,485		
SE6A	19,923	23,187	1,164	21,555		ISE6A	17,691	24,656	1,394	21,174		
SE5A	23,489	20,781	1,130	22,135		ISE5A	19,791	25,509	1,289	22,650		
IE1A	18,112	22,420	1,238	20,266		IEE1A	19,849	25,581	1,289	22,715		
IE2A	18,288	26,077	1,424	22,183		IEE2A	19,955	24,417	1,224	22,186		
IE4A	20,715	23,450	1,132	22,083		IEE4A	24,131	22,912	1,053	23,522		
I6A	18,644	26,108	1,400	22,376		IEE6A	20,924	22,784	1,098	21,954		
IE5A	19,633	26,331	1,341	22,982		IEE5A	21,793	25,037	1,149	23,415		
ID1A	20,781	23,319	1,122	22,053		ID1A	21,170	22,802	1,077	21,988		
ID2A	19,644	23,733	1,208	21,689		ID2A	19,338	24,789	1,282	22,064		
ID4A	21,959	23,539	1,072	22,749		ID4A	21,093	25,682	1,218	23,388		
ID6A	19,419	24,082	1,240	21,751		ID6A	21,248	22,945	1,080	22,097		
ID5A	18,696	23,062	1,234	20,879		ID5A	19,655	23,374	1,189	21,515		
SD1A	20,025	25,458	1,271	22,742		SD1A	22,946	22,317	1,028	22,632		
SD2A	19,976	23,767	1,190	21,872		SD2A	19,684	24,268	1,233	21,976		
SD4A	20,288	22,416	1,105	21,352		SD4A	22,631	24,239	1,071	23,435		
SD6A	18,198	23,735	1,304	20,967		SD6A	19,737	23,814	1,207	21,776		
SD5A	19,304	22,132	1,146	20,718		SD5A	20,234	23,631	1,168	21,933		
D14			21,992	E14							22,153	
SE1A	19,790	24,587	1,242	22,189		ISE1A	20,409	25,171	1,233	22,790		
SE2A	20,026	23,093	1,153	21,560		ISE2A	19,118	25,650	1,342	22,384		
SE4A	21,804	21,020	1,037	21,412		ISE4A	21,344	22,065	1,034	21,705		
SE6A	18,317	22,940	1,252	20,629		ISE6A	18,444	25,076	1,360	21,760		
SE5A	21,400	22,400	1,047	21,900		ISE5A	20,127	25,649	1,274	22,888		
IE1A	20,249	24,030	1,187	22,140		IEE1A	21,664	23,390	1,080	22,527		
IE2A	18,966	25,195	1,328	22,081		IEE2A	19,230	23,883	1,242	21,557		
IE4A	20,103	22,292	1,109	21,198		IEE4A	22,662	25,259	1,115	23,961		
IE6A	18,298	25,099	1,372	21,699		IEE6A	20,494	23,226	1,133	21,860		
IE5A	19,812	23,870	1,205	21,841		IEE5A	21,533	23,629	1,097	22,581		
ID1A	23,161	24,586	1,062	23,874		ID1A	18,363	23,640	1,287	21,002		

	POLY COLUNA DA DIREITA							POLY COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE			R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE	
IDCA	19,478	22,541	1,157	21,010			ID2A	20,664	22,948	1,111	21,806		
ID4A	20,953	23,585	1,126	22,269			ID4A	18,815	23,528	1,250	21,172		
ID6A	19,882	22,656	1,140	21,289			ID6A	19,776	24,019	1,215	21,898		
ID5A	22,578	22,525	1,002	22,552			ID5A	22,465	23,156	1,031	22,811		
SD1A	21,232	24,516	1,155	22,874			SD1A	21,367	22,659	1,060	22,013		
SD2A	20,207	23,512	1,164	21,840			SD2A	20,613	21,703	1,053	21,158		
SD4A	22,769	23,016	1,011	22,893			SD4A	22,043	23,939	1,086	22,991		
SD6A	19,940	23,394	1,173	21,667			SD6A	20,367	22,944	1,127	21,656		
SD5A	19,213	26,649	1,387	22,931			SD5A	21,230	23,852	1,124	22,541		
D15					22,077	E15						22,459	
SE1A	19,439	24,973	1,285	22,206			SE1A	20,830	22,324	1,072	21,577		
SE2A	18,189	23,367	1,285	20,778			SE2A	20,314	25,663	1,263	22,989		
SE4A	19,021	24,549	1,292	21,795			SE4A	19,817	25,797	1,302	22,807		
SE6A	19,010	24,764	1,303	21,887			SE6A	17,846	26,359	1,488	22,203		
SA	21,283	23,986	1,127	22,635			SE5A	19,794	25,019	1,264	22,407		
EE1A	22,813	22,434	1,017	22,624			EE1A	21,174	24,932	1,178	23,043		
EE2A	19,600	23,729	1,211	21,665			EE2A	19,858	24,656	1,242	22,257		
EE4A	20,127	23,710	1,178	21,919			EE4A	19,923	25,079	1,259	22,501		
EE6A	21,791	22,173	1,018	21,982			EE6A	20,433	24,960	1,222	22,697		
EE5A	19,976	22,646	1,134	21,311			EE5A	20,382	25,876	1,270	23,129		
ID1A	21,745	24,639	1,133	23,192			ID1A	21,880	21,942	1,003	21,911		
ID2A	19,310	23,482	1,216	21,396			ID2A	18,711	22,484	1,202	20,598		
ID4A	22,139	22,249	1,005	22,194			ID4A	22,190	23,654	1,066	22,922		
ID6A	18,679	25,333	1,356	22,006			ID6A	20,116	24,252	1,206	22,184		
ID5A	20,299	26,604	1,311	23,452			ID5A	20,556	23,165	1,127	21,861		
SD1A	20,788	23,065	1,110	21,927			SD1A	22,223	24,571	1,106	23,397		
SD2A	19,892	24,440	1,229	22,166			SD2A	19,265	24,982	1,297	22,124		
SD4A	21,482	20,070	1,070	20,776			SD4A	21,096	24,933	1,182	23,015		
SD6A	20,203	25,616	1,248	22,910			SD6A	19,308	25,261	1,308	22,285		
SD5A	21,009	24,433	1,163	22,721			SD5A	22,532	23,976	1,064	23,254		
D16					22,531	E16						22,352	
SE1A	22,249	23,093	1,038	22,671			SE1A	22,384	24,168	1,080	23,276		
SE2A	20,656	24,425	1,182	22,541			SE2A	20,345	23,569	1,158	21,957		
SE4A	21,423	24,004	1,120	22,714			SE4A	20,650	24,846	1,203	22,748		
SE6A	20,051	24,072	1,201	22,062			SE6A	19,696	25,378	1,288	22,537		
SE5A	21,349	23,037	1,079	22,193			SE5A	20,661	24,892	1,205	22,777		
EE1A	21,310	25,016	1,174	23,163			EE1A	21,070	24,171	1,147	22,621		
EE2A	19,470	25,024	1,285	22,247			EE2A	19,923	24,217	1,216	22,070		
EE4A	20,156	24,828	1,232	22,492			EE4A	19,854	23,663	1,192	21,759		
EE6A	19,430	24,936	1,283	22,183			EE6A	19,169	24,225	1,264	21,697		
EE5A	20,638	25,331	1,227	22,985			EE5A	19,785	22,552	1,140	21,169		
ID1A	21,289	26,182	1,229	23,726			ID1A	21,544	24,255	1,219	23,900		
ID2A	19,616	24,276	1,238	21,946			ID2A	20,942	24,751	1,182	22,847		
ID4A	21,304	22,633	1,062	21,969			ID4A	20,325	23,693	1,166	22,009		
ID6A	19,274	23,964	1,243	21,619			ID6A	18,215	23,482	1,289	20,849		
ID5A	20,827	23,471	1,127	22,149			ID5A	20,280	24,820	1,224	22,550		
SD1A	23,500	23,931	1,018	23,716			SD1A	21,973	24,393	1,110	23,183		
SD2A	19,524	24,244	1,242	21,884			SD2A	20,193	24,108	1,194	22,151		
SD4A	23,130	23,773	1,028	23,452			SD4A	21,694	23,525	1,084	22,610		
SD6A	19,808	23,875	1,205	21,842			SD6A	18,692	25,377	1,358	22,035		
SD5A	20,240	25,891	1,279	23,066			SD5A	20,929	23,658	1,130	22,294		
D17					22,055	E17						22,649	
SE1A	22,212	23,283	1,048	22,748			SE1A	20,806	26,974	1,296	23,890		
SE2A	18,780	24,258	1,292	21,519			SE2A	19,957	24,489	1,227	22,223		
SE4A	20,896	23,461	1,123	22,179			SE4A	21,283	22,554	1,040	21,919		
SE6A	19,699	24,646	1,251	22,173			SE6A	20,601	24,071	1,168	22,336		
SE5A	21,833	24,156	1,106	22,996			SE5A	21,547	26,525	1,231	24,036		

	POLY COLUNA DA DIREITA							POLY COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE			R1	R2	R1/R2	RS	AVG/DIE	
IE1A	20,170	22,561	1,119	21,366		IIE1A	22,792	23,179	1,017	22,986			
IE2A	19,439	23,276	1,197	21,358		IIE2A	19,019	25,703	1,351	22,361			
IE4A	18,592	26,381	1,419	22,487		IIE4A	20,357	22,179	1,090	21,248			
IE6A	20,699	23,568	1,136	22,104		IIE6A	18,774	23,483	1,251	21,129			
IE5A	21,736	19,846	1,095	20,791		IIESA	20,201	24,512	1,213	22,357			
ID1A	22,406	25,991	1,160	24,199		IID1A	23,117	24,282	1,050	23,700			
ID2A	19,309	23,120	1,197	21,215		IID2A	20,144	23,647	1,174	21,896			
ID4A	20,378	22,178	1,088	21,278		IID4A	22,901	24,628	1,075	23,765			
ID6A	19,222	23,959	1,246	21,591		IID6A	20,759	23,154	1,115	21,957			
ID5A	19,315	22,864	1,184	21,090		IID5A	20,519	25,422	1,239	22,971			
SD1A	22,145	25,321	1,143	23,733		ISD1A	19,341	26,602	1,375	22,972			
SD2A	17,946	23,872	1,330	20,909		ISD2A	20,228	25,249	1,249	22,749			
SD4A	22,532	24,093	1,049	23,313		ISD4A	19,579	24,171	1,235	21,875			
SD6A	19,529	23,434	1,200	21,482		ISD6A	20,687	24,698	1,194	22,693			
SA	19,789	25,363	1,282	22,576		ISD5A	22,423	25,390	1,132	23,907			
D18					21,950	E18						22,393	
SE1A	23,992	22,893	1,048	23,443		ISE1A	21,911	22,585	1,031	22,248			
SE2A	18,949	23,578	1,244	21,264		ISE2A	19,678	24,774	1,259	22,226			
SE4A	20,083	23,159	1,153	21,621		ISE4A	21,909	23,900	1,050	22,455			
SE6A	21,156	22,182	1,048	21,669		ISE6A	18,613	25,866	1,390	22,240			
SE5A	21,831	23,019	1,054	22,425		ISE5A	21,130	24,964	1,181	23,047			
IE1A	22,046	24,845	1,127	23,446		IIE1A	21,172	25,320	1,198	23,246			
IE2A	19,596	24,558	1,253	22,077		IIE2A	19,880	24,618	1,238	22,249			
IE4A	20,086	24,073	1,198	22,080		IIE4A	20,331	23,613	1,161	21,972			
IE6A	19,558	23,511	1,202	21,535		IIE6A	21,200	23,961	1,130	22,581			
IE5A	19,603	26,112	1,332	22,858		IIE5A	21,906	24,694	1,127	23,300			
ID1A	22,354	23,192	1,037	22,773		IID1A	20,472	25,487	1,245	22,980			
ID2A	20,095	22,138	1,102	21,117		IID2A	19,268	24,850	1,290	22,059			
ID4A	18,117	24,025	1,324	21,071		IID4A	20,114	23,207	1,154	21,661			
ID6A	19,208	23,433	1,220	21,321		IID6A	20,152	24,744	1,228	22,448			
ID5A	21,531	23,014	1,069	22,273		IID5A	21,596	24,319	1,126	22,958			
SD1A	21,000	21,708	1,034	21,354		ISD1A	21,064	23,393	1,111	22,229			
SD2A	19,528	22,979	1,177	21,254		ISD2A	20,366	23,564	1,157	21,965			
SD4A	21,744	21,210	1,025	21,477		ISD4A	20,890	22,047	1,055	21,449			
SD6A	19,501	23,486	1,204	21,494		ISD6A	19,466	24,904	1,279	22,185			
SD5A	17,680	27,244	1,541	22,462		ISD5A	23,916	20,782	1,151	22,349			
D19					22,162	E19						22,170	
SE1A	20,474	22,979	1,122	21,727		ISE1A	19,934	26,540	1,331	23,237			
SE2A	19,098	25,538	1,337	22,316		ISE2A	19,310	24,254	1,256	21,782			
SE4A	21,314	23,034	1,081	22,174		ISE4A	21,649	22,671	1,047	22,160			
SE6A	19,718	24,013	1,206	21,966		ISE6A	18,892	22,896	1,212	20,894			
SE5A	19,313	22,260	1,153	20,787		ISE5A	17,467	24,829	1,421	21,148			
IE1A	20,322	24,987	1,230	22,655		IIE1A	22,466	22,180	1,013	22,323			
IE2A	20,594	22,612	1,098	21,603		IIE2A	19,211	24,445	1,272	21,828			
IE4A	19,995	21,849	1,093	20,922		IIE4A	20,540	23,384	1,138	21,962			
IE6A	20,602	23,672	1,149	22,137		IIE6A	18,489	24,849	1,344	21,669			
IE5A	21,345	24,647	1,155	22,996		IIESA	22,954	23,347	1,017	23,151			
ID1A	22,133	22,728	1,027	22,431		IID1A	22,222	24,975	1,124	23,599			
ID2A	20,238	23,508	1,160	21,883		IID2A	18,480	24,731	1,338	21,406			
ID4A	21,175	22,881	1,081	22,028		IID4A	21,302	24,950	1,171	23,126			
ID6A	19,468	24,018	1,234	21,743		IID6A	20,009	24,419	1,220	22,214			
ID5A	19,302	25,813	1,337	22,558		IID5A	19,655	22,252	1,132	20,954			
ID1A	21,920	23,458	1,070	22,689		ISD1A	22,700	22,977	1,012	22,839			
ID2A	20,746	23,134	1,115	21,940		ISD2A	19,230	25,560	1,329	22,395			
ID4A	21,044	25,298	1,202	23,171		ISD4A	23,196	24,120	1,040	23,458			
ID6A	18,234	26,000	1,426	22,117		ISD6A	19,773	24,321	1,230	22,047			
ID5A	19,976	26,810	1,342	23,393		ISD5A	19,345	22,290	1,152	20,818			

D20	POLY COLUNA DA DIREITA						E20	POLY COLUNA DA ESQUERDA					
	R1	R2	R1/R2	RS	I AVG/DIE			R1	R2	R1/R2	RS	I AVG/DIE	
SE1A	21,418	23,978	1,120	22,698	22,383		ISE1A	22,090	23,510	1,064	22,800	22,376	
SE2A	20,410	24,821	1,216	22,616			ISE2A	19,104	25,439	1,332	22,272		
SE4A	20,222	24,474	1,210	22,348			ISE4A	22,296	24,602	1,103	23,449		
SE6A	19,267	24,289	1,261	21,778			ISE6A	20,012	23,426	1,171	21,719		
SE5A	22,483	22,134	1,016	22,309			ISE5A	20,593	25,978	1,261	23,286		
IE1A	20,756	26,224	1,263	23,490			IIE1A	21,210	24,867	1,172	23,039		
IE2A	19,194	24,257	1,264	21,726			IIE2A	19,292	25,276	1,310	22,884		
IE4A	20,289	23,809	1,175	22,039			IIE4A	20,186	20,294	1,005	20,240		
IE6A	19,233	24,131	1,255	21,682			IIE6A	20,291	23,968	1,181	22,130		
IE5A	24,334	21,858	1,113	23,096			IIE5A	21,541	22,558	1,047	22,050		
ID1A	22,427	22,744	1,014	22,586			IID1A	21,605	22,661	1,049	22,133		
ID2A	20,028	23,946	1,196	21,987			IID2A	20,363	23,241	1,141	21,802		
ID4A	22,172	23,129	1,043	22,651			IID4A	23,225	22,907	1,014	23,066		
SDA	18,962	24,323	1,283	21,643			IID6A	19,666	24,626	1,252	22,146		
SD5A	21,052	23,135	1,099	22,094			IID5A	21,169	23,023	1,088	22,096		
SD1A	21,174	25,379	1,199	23,277			ISD1A	22,937	24,077	1,050	23,507		
SD2A	20,299	23,835	1,174	22,067			ISD2A	19,101	24,777	1,297	21,939		
SD4A	21,486	23,293	1,084	22,390			ISD4A	21,663	22,504	1,039	22,084		
SD6A	19,052	24,692	1,296	21,872			ISD6A	20,391	23,698	1,162	22,045		
SD5A	19,583	27,045	1,382	23,324			ISD5A	23,500	23,361	1,006	23,431		
MEDIA	1,182	21,833	21,833				MEDIA	1,192	22,037	22,037			
SIGMA	0,100	0,844	0,453				SIGMA	0,104	0,925	0,542			

APÊNDICE II

**TABELA DAS MEDIDAS DE LARGURA DE LINHA EM
ESTRUTURAS DE POLISSILÍCIO**

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

1A

POLY	DIE	POS	R1X	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	DELTA	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTAxDELTAy	
D011D	1A	1720,8	702,7	1696,4	707,2	20,473	0,773	1,894	0,785	1,882	-0,310	-0,285	1	0,746	1,856	0,767	1,874	-0,329	-0,307
D011E	1A	1732,4	724,3	1696,3	702,7	21,362	0,802	1,917	0,819	1,976	-0,282	-0,293	2	0,827	2,001	0,853	1,981	-0,297	-0,244
D015D	1A	1848,2	711,1	1770,7	720,0	20,320	0,715	1,857	0,746	1,834	-0,375	-0,315	3	0,861	2,041	0,882	2,030	-0,270	-0,230
D015E	1A	1863,7	735,2	1792,5	716,0	19,875	0,693	1,757	0,721	1,804	-0,349	-0,335	4	0,874	2,031	0,886	2,013	-0,245	-0,214
D021D	1A	1685,4	689,4	1646,8	715,4	21,966	0,847	2,071	0,867	1,996	-0,308	-0,232	5	0,882	2,062	0,907	2,064	-0,252	-0,215
D021E	1A	1702,0	700,0	1629,1	708,8	22,725	0,868	2,110	0,907	2,084	-0,301	-0,230	6	0,846	1,989	0,870	1,962	-0,259	-0,202
D025D	1A	1743,8	709,8	1630,2	702,0	19,746	0,736	1,808	0,787	1,828	-0,314	-0,244	7	0,850	1,979	0,885	1,978	-0,246	-0,191
D025E	1A	1662,5	705,2	1670,1	705,5	21,871	0,855	2,016	0,851	2,015	-0,263	-0,269	8	0,873	2,037	0,904	2,027	-0,248	-0,194
D031D	1A	1639,9	682,2	1579,3	701,2	21,350	0,846	2,034	0,879	1,979	-0,288	-0,201	9	0,900	2,084	0,915	2,054	-0,238	-0,197
D031E	1A	1623,6	705,7	1622,4	683,5	22,217	0,889	2,046	0,890	2,113	-0,231	-0,272	10	0,862	2,014	0,884	1,983	-0,253	-0,195
D035D	1A	1663,7	684,6	1616,4	706,7	21,998	0,859	2,089	0,885	2,023	-0,301	-0,223	11	0,903	2,066	0,910	2,042	-0,223	-0,196
D035E	1A	1679,0	712,8	1624,1	709,7	21,895	0,848	1,997	0,876	2,005	-0,262	-0,224	12	0,900	2,055	0,909	2,024	-0,221	-0,185
D41D	1A	1641,4	692,1	1610,1	708,1	22,012	0,872	2,067	0,889	2,021	-0,271	-0,215	13	0,867	2,021	0,888	1,985	-0,247	-0,190
D041E	1A	1584,6	704,8	1559,0	702,6	22,684	0,930	2,092	0,946	2,099	-0,199	-0,180	14	0,892	2,076	0,928	2,031	-0,245	-0,161
D045D	1A	1618,1	706,7	1658,3	708,5	21,776	0,875	2,003	0,854	1,998	-0,225	-0,254	15	0,882	2,031	0,899	2,015	-0,231	-0,194
D045E	1A	1658,1	691,7	1582,7	700,7	20,882	0,819	1,962	0,858	1,937	-0,284	-0,206	16	0,903	2,090	0,919	2,062	-0,239	-0,196
D051D	1A	1622,1	710,3	1601,1	698,7	23,432	0,939	2,144	0,951	2,180	-0,221	-0,226	17	0,896	2,074	0,906	2,036	-0,238	-0,199
D051E	1A	1647,8	700,5	1611,9	712,1	20,976	0,827	1,946	0,846	1,915	-0,261	-0,209	18	0,887	2,063	0,912	2,041	-0,247	-0,192
D055D	1A	1675,6	700,4	1623,4	701,7	22,804	0,885	2,116	0,913	2,112	-0,282	-0,239	19	0,873	2,022	0,889	1,985	-0,240	-0,173
D055E	1A	1654,7	711,0	1581,7	708,4	22,331	0,877	2,042	0,918	2,049	-0,247	-0,189	20	0,876	2,071	0,912	2,029	-0,267	-0,182
D061D	1A	1663,0	677,4	1619,0	712,6	21,058	0,823	2,021	0,845	1,921	-0,313	-0,214							
D061E	1A	1672,3	717,8	1613,4	716,2	21,973	0,854	1,990	0,885	1,994	-0,248	-0,202		0,870	2,033	0,891	2,010	-0,252	-0,203
D065D	1A	1642,0	720,9	1583,7	710,0	20,944	0,829	1,888	0,860	1,917	-0,217	-0,187		0,935	0,951	0,933	0,944	0,924	0,930
D065E	1A	1655,2	704,8	1627,5	719,9	22,316	0,876	2,058	0,891	2,015	-0,258	-0,207							
D071D	1A	1672,5	699,9	1573,6	719,9	21,268	0,827	1,975	0,879	1,920	-0,280	-0,157							
D071E	1A	1653,1	729,1	1608,4	716,4	22,031	0,866	1,964	0,890	1,999	-0,211	-0,197							
D075D	1A	1681,4	711,5	1599,3	711,2	20,779	0,803	1,896	0,844	1,899	-0,266	-0,199							
D075E	1A	1664,2	725,2	1628,5	718,9	23,171	0,905	2,077	0,925	2,095	-0,228	-0,210							
D081D	1A	1665,0	701,9	1607,7	732,4	23,079	0,901	2,137	0,933	2,048	-0,271	-0,163							
D081E	1A	1668,5	726,2	1597,0	721,0	21,692	0,845	1,942	0,883	1,956	-0,229	-0,177							
D085D	1A	1725,6	723,9	1614,1	723,6	23,104	0,870	2,074	0,930	2,075	-0,277	-0,187							
D085E	1A	1672,4	735,6	1686,2	723,7	22,575	0,877	1,995	0,870	2,028	-0,215	-0,248							
D091D	1A	1668,5	711,8	1627,7	722,0	22,912	0,893	2,092	0,915	2,063	-0,256	-0,203							
D091E	1A	1661,0	727,6	1597,3	735,0	22,990	0,900	2,054	0,936	2,033	-0,220	-0,148							
D095D	1A	1682,9	699,2	1684,2	727,4	23,071	0,891	2,145	0,890	2,062	-0,289	-0,240							
D095E	1A	1622,2	728,1	1622,2	722,6	22,898	0,918	2,044	0,918	2,060	-0,186	-0,197							
D101D	1A	1669,0	715,5	1594,5	714,8	20,667	0,805	1,878	0,843	1,879	-0,250	-0,187							
D101E	1A	1673,5	724,6	1633,5	737,0	23,247	0,903	2,085	0,925	2,050	-0,236	-0,178							
D105D	1A	1666,6	705,2	1608,9	728,2	21,555	0,841	1,987	0,871	1,924	-0,266	-0,173							
D105E	1A	1691,3	720,3	1690,4	730,1	23,360	0,892	2,108	0,898	2,080	-0,258	-0,240							
D111D	1A	1631,9	715,54	1630,4	724,23	23,359	0,930	2,122	0,931	2,096	-0,219	-0,201							
D111E	1A	1672,7	717,63	1632,3	731,92	23,554	0,915	2,133	0,938	2,092	-0,249	-0,187							
D115D	1A	1660,8	713,75	1638,1	732,75	22,075	0,864	2,010	0,876	1,958	-0,246	-0,191							
D115E	1A	1656,9	748,46	1672,8	740,01	23,004	0,902	1,998	0,894	2,021	-0,176	-0,207							
D121D	1A	1637,1	715,14	1603,9	729,38	22,855	0,907	2,077	0,926	2,062	-0,224	-0,185							
D121E	1A	1654,8	723,42	1610,4	728,68	22,243	0,874	1,999	0,898	1,984	-0,223	-0,174							
D125D	1A	1631,2	703,47	1614,5	727,46	22,941	0,914	2,120	0,924	2,050	-0,242	-0,180							
D125E	1A	1621,8	723,12	1647,2	731,65	22,527	0,903	2,025	0,889	2,001	-0,195	-0,201							
D131D	1A	1648,9	704,21	1606,2	712,09	22,053	0,869	2,036	0,892	2,013	-0,255	-0,204							
D131E	1A	1633,8	710,26	1579,3	730,31	20,266	0,806	1,855	0,834	1,804	-0,231	-0,140							
D135D	1A	1680,7	696,19	1631,7	725,52	22,742	0,879	2,123	0,906	2,037	-0,293	-0,199							
D135E	1A	1651,7	728,81	1645,2	723,23	23,229	0,914	2,072	0,918	2,088	-0,210	-0,216							
D141D	1A	1635,7	693,24	1614,9	728,16	23,874	0,949	2,238	0,961	2,131	-0,264	-0,178							
D141E	1A	1636,6	716,65	1584,2	723,05	22,140	0,879	2,008	0,908	1,990	-0,221	-0,160							
D145D	1A	1687,8	717,15	1615,5	728,93	22,874	0,981	2,073	0,920	2,040	-0,261	-0,178							

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	R1X	R2Y	R1Y	R2Y	RS	LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	DELTA	LN1X LN2X LN1Y LN2Y DELTAXXDELTAY					
													LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTAXXDELTAY	
D14SE 1A	1675,5	726,19	1577,2	734,98	22,189	0,861	1,986	0,914	1,962	-0,235	-0,127							
D15ID 1A	1650,3	706,08	1587,4	716,47	23,192	0,913	2,135	0,950	2,104	-0,252	-0,177							
D15IE 1A	1655,2	715,52	1618,2	729,17	22,624	0,888	2,055	0,909	2,017	-0,239	-0,180							
D15SD 1A	1646,6	732,30	1649,0	732,99	21,927	0,866	1,946	0,864	1,944	-0,199	-0,200							
D15SI 1A	1675,1	725,62	1651,7	723,64	22,206	0,862	1,989	0,874	1,995	-0,236	-0,220							
D16ID 1A	1672,3	715,95	1595,0	727,70	23,726	0,922	2,154	0,967	2,119	-0,251	-0,161							
D16IE 1A	1664,2	724,22	1641,2	735,22	23,163	0,905	2,079	0,917	2,048	-0,230	-0,188							
D16SD 1A	1701,4	732,72	1683,8	741,47	23,716	0,906	2,104	0,915	2,079	-0,244	-0,213							
D16SE 1A	1675,5	728,29	1680,0	735,96	22,671	0,880	2,023	0,877	2,002	-0,231	-0,220							
D17ID 1A	1659,4	703,91	1623,6	741,43	24,199	0,948	2,235	0,969	2,121	-0,263	-0,160							
D17IE 1A	1687,3	728,48	1653,5	735,29	21,366	0,823	1,906	0,840	1,889	-0,240	-0,199							
D17SD 1A	1667,0	714,19	1649,1	729,62	23,733	0,925	2,160	0,935	2,114	-0,250	-0,206							
D17SE 1A	1664,7	741,45	1683,6	732,03	22,748	0,888	1,974	0,878	2,020	-0,197	-0,231							
D18ID 1A	1648,0	701,11	1573,8	729,13	22,773	0,898	2,111	0,941	2,030	-0,260	-0,137							
D18IE 1A	1637,7	721,21	1626,6	730,17	23,446	0,931	2,113	0,937	2,087	-0,213	-0,185							
D18SD 1A	1697,5	705,13	1636,7	699,59	21,354	0,818	1,968	0,848	1,984	-0,289	-0,253							
D18SE 1A	1693,7	739,36	1652,2	738,28	23,443	0,900	2,061	0,922	2,064	-0,225	-0,192							
D19ID 1A	1653,5	725,55	1622,3	728,57	22,431	0,882	2,009	0,899	2,001	-0,218	-0,185							
D19IE 1A	1678,4	732,18	1627,0	737,64	22,455	0,877	2,011	0,905	1,996	-0,228	-0,171							
D19SD 1A	1647,2	712,87	1654,9	737,78	22,689	0,895	2,069	0,891	1,999	-0,237	-0,196							
D19SE 1A	1685,9	706,98	1639,6	758,09	21,727	0,838	1,998	0,861	1,863	-0,278	-0,140							
D20ID 1A	1709,0	724,63	1577,6	733,30	22,586	0,859	2,026	0,931	2,002	-0,264	-0,131							
D20IE 1A	1710,4	722,12	1645,3	734,20	23,490	0,893	2,114	0,928	2,080	-0,269	-0,194							
D20SD 1A	1700,5	718,26	1667,5	742,33	23,277	0,890	2,106	0,907	2,038	-0,269	-0,198							
D20SE 1A	1711,0	724,62	1669,4	739,37	22,498	0,862	2,036	0,884	1,995	-0,265	-0,205							
D01ID 2A	706,7	332,1	673,3	345,9	20,957	1,928	4,102	2,023	3,938	-0,227	0,113	1	1,908	4,025	1,973	3,987	-0,197	0,040
D01IE 2A	690,9	329,8	660,8	341,1	20,951	1,971	4,129	2,061	3,992	-0,173	0,134	2	1,949	4,064	2,002	3,945	-0,157	0,041
D01SD 2A	708,0	336,5	690,8	343,2	19,832	1,821	3,831	1,866	3,756	-0,188	-0,025	3	1,959	4,075	2,008	3,971	-0,149	0,046
D01SE 2A	695,8	329,7	686,2	344,7	20,481	1,913	4,038	1,940	3,862	-0,199	0,019	4	2,009	4,099	2,027	3,997	-0,077	0,058
D02ID 2A	694,9	331,2	676,3	344,3	21,556	2,016	4,230	2,072	4,069	-0,179	0,074	5	2,015	4,116	2,050	4,019	-0,081	0,084
D02IE 2A	675,3	329,9	676,6	339,3	20,417	1,965	4,023	1,961	3,911	-0,090	0,012	6	1,947	3,980	1,998	3,876	-0,084	0,128
D02SD 2A	703,8	332,7	679,9	342,5	21,200	1,958	4,142	2,027	4,023	-0,207	0,030	7	1,997	4,068	2,016	3,934	-0,070	0,101
D02SE 2A	695,7	334,2	662,6	341,7	19,858	1,855	3,862	1,948	3,777	-0,151	0,130	8	1,985	4,050	2,022	3,961	-0,075	0,086
D03ID 2A	696,0	331,2	675,9	336,2	20,725	1,936	4,067	1,993	4,007	-0,184	-0,021	9	1,982	4,064	2,016	3,910	-0,094	0,128
D03IE 2A	675,4	328,7	664,8	339,1	20,642	1,987	4,082	2,018	3,957	-0,104	0,082	10	1,981	3,995	1,992	3,906	-0,033	0,082
D03SD 2A	698,8	332,7	678,8	342,9	20,320	1,890	3,970	1,946	3,852	-0,182	0,042	11	1,952	3,989	1,992	3,865	-0,085	0,126
D03SE 2A	685,1	331,4	668,2	340,6	21,324	2,023	4,182	2,074	4,069	-0,126	0,079	12	1,985	4,054	2,030	3,927	-0,080	0,142
D04ID 2A	684,6	335,7	678,1	343,1	21,100	2,003	4,085	2,023	3,997	-0,076	0,048	13	2,024	4,121	2,047	3,967	-0,069	0,132
D04IE 2A	678,9	330,2	677,6	344,7	20,422	1,955	4,020	1,959	3,851	-0,106	0,071	14	2,006	4,031	2,014	3,925	-0,018	0,107
D04SE 2A	688,3	342,5	680,8	347,0	21,363	2,017	4,054	2,040	4,002	-0,019	0,079	15	1,968	3,995	2,023	3,861	-0,059	0,201
D04SE 2A	680,9	331,0	671,8	338,7	21,565	2,059	4,235	2,087	4,139	-0,108	0,034	16	2,019	4,103	2,046	3,964	-0,060	0,133
D05ID 2A	684,0	340,1	689,9	343,7	21,211	2,018	4,054	1,998	4,011	-0,022	-0,014	17	1,925	3,944	1,982	3,776	-0,093	0,212
D05IE 2A	686,4	335,8	666,6	345,8	21,260	2,013	4,115	2,073	3,996	-0,084	0,156	18	1,961	4,011	2,020	3,866	-0,086	0,188
D05SD 2A	689,7	338,3	676,3	347,7	21,474	2,024	4,126	2,064	4,014	-0,075	0,116	19	1,986	4,060	2,004	3,924	-0,085	0,088
D05SE 2A	694,9	334,4	674,8	343,7	21,442	2,006	4,168	2,065	4,053	-0,145	0,079	20	1,987	4,048	2,036	3,928	-0,072	0,153
D06ID 2A	700,2	344,3	678,5	352,7	21,267	1,974	4,015	2,037	3,919	-0,065	0,165							
D06IE 2A	694,6	343,2	684,1	351,6	20,595	1,926	3,899	1,956	3,806	-0,047	0,115							
D06SD 2A	703,9	343,5	679,9	351,6	20,431	1,887	3,866	1,953	3,777	-0,094	0,142							
D06SE 2A	697,7	337,2	683,2	349,0	21,489	2,002	4,142	2,044	4,002	-0,129	0,089							
D07ID 2A	697,9	344,7	698,9	353,6	21,173	1,972	3,993	1,969	3,892	-0,048	0,048							
D07IE 2A	702,1	338,2	696,7	353,8	21,333	1,975	4,100	1,990	3,919	-0,141	0,064							
D07SD 2A	698,1	343,3	680,7	354,7	21,766	2,027	4,121	2,078	3,989	-0,065	0,176							
D07SE 2A	691,4	343,4	688,3	354,0	21,439	2,015	4,058	2,025	3,936	-0,026	0,118							
D08ID 2A	703,1	346,8	702,7	356,2	21,451	1,983	4,021	1,984	3,914	-0,053	0,056							
D08IE 2A	698,1	349,1	678,7	352,9	20,946	1,950	3,900	2,006	3,858	0,001	0,166							

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	POLY		R1Y	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	BELTA	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	BELTA	LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	BELTA			
		R1X	R2Y																										
D08SD	2A	724,7	344,7	702,8	353,8	21,788	1,954	4,109	2,015	4,003	-0,186	0,028																	
D08SE	2A	702,1	345,7	693,0	354,6	22,190	2,054	4,172	2,081	4,067	-0,060	0,096																	
D09ID	2A	719,0	341,1	695,9	356,1	22,081	1,996	4,208	2,062	4,030	-0,195	0,096																	
D09IE	2A	691,8	344,6	690,3	359,6	21,816	2,050	4,115	2,054	3,943	-0,015	0,175																	
D09SB	2A	712,5	344,5	696,4	359,6	20,816	1,899	3,927	1,943	3,763	-0,128	0,135																	
D09SE	2A	705,8	347,5	698,8	358,5	21,535	1,983	4,005	2,003	3,904	-0,038	0,107																	
D10ID	2A	710,2	354,6	710,9	356,3	21,742	1,992	3,989	1,990	3,970	-0,006	0,010																	
D10IE	2A	696,5	350,2	704,7	361,4	21,596	2,015	4,008	1,992	3,884	0,023	0,105																	
D10SD	2A	713,5	349,4	700,9	359,6	21,158	1,927	3,934	1,962	3,824	-0,081	0,107																	
D10SE	2A	711,6	349,8	699,3	358,7	21,761	1,990	4,047	2,024	3,947	-0,066	0,106																	
D11ID	2A	711,7	348,99	695,0	358,77	21,647	1,977	4,032	2,025	3,922	-0,076	0,134																	
D11IE	2A	707,2	342,86	695,9	356,15	20,088	1,846	3,808	1,876	3,666	-0,118	0,096																	
D11SD	2A	726,0	349,39	701,8	357,25	21,558	1,930	4,011	1,997	3,922	-0,145	0,073																	
D11SE	2A	698,4	349,20	693,0	363,00	22,057	2,053	4,106	2,067	3,750	-0,000	0,200																	
D12ID	2A	702,9	344,59	686,1	353,07	21,792	2,015	4,111	2,064	4,012	-0,077	0,120																	
D12IE	2A	694,3	343,39	696,5	360,35	21,122	1,977	3,998	1,971	3,810	-0,043	0,144																	
D12SD	2A	716,8	351,51	690,4	353,78	21,637	1,962	4,001	2,037	3,975	-0,075	0,102																	
D12SE	2A	706,4	341,82	685,1	358,85	21,596	1,987	4,107	2,049	3,912	-0,125	0,200																	
D13ID	2A	702,2	343,17	692,0	357,01	21,689	2,008	4,108	2,037	3,949	-0,088	0,132																	
D13IE	2A	689,7	343,44	690,1	354,53	22,183	2,091	4,198	2,089	4,067	-0,016	0,113																	
D13SD	2A	712,3	346,71	700,7	361,56	21,872	1,996	4,100	2,029	3,932	-0,104	0,132																	
D13SE	2A	696,9	342,47	687,2	356,20	21,478	2,003	4,076	2,031	3,919	-0,068	0,152																	
D14ID	2A	699,8	345,08	698,2	356,71	21,010	1,951	3,957	1,956	3,828	-0,054	0,089																	
D14IE	2A	699,9	348,61	698,5	358,72	22,081	2,051	4,117	2,055	4,001	-0,015	0,111																	
D14SD	2A	708,6	351,74	706,3	360,24	21,860	2,034	4,040	2,012	3,944	-0,028	0,082																	
D14SE	2A	704,3	349,36	689,1	356,80	21,560	1,990	4,011	2,034	3,928	-0,031	0,147																	
D15ID	2A	717,4	351,03	690,5	360,89	21,396	1,939	3,962	2,014	3,856	-0,084	0,187																	
D15IE	2A	701,2	346,92	692,7	358,19	21,665	2,008	4,059	2,033	3,931	-0,042	0,141																	
D15SD	2A	717,7	353,32	691,7	366,52	22,166	2,007	4,078	2,083	3,931	-0,061	0,254																	
D15SE	2A	704,9	348,03	688,9	362,53	20,778	1,916	3,881	1,960	3,725	-0,049	0,221																	
D16ID	2A	719,9	354,21	698,9	365,16	21,948	1,981	4,027	2,041	3,907	-0,063	0,189																	
D16IE	2A	696,0	349,91	710,9	363,79	22,247	2,078	4,133	2,034	3,975	0,022	0,096																	
D16SB	2A	717,9	353,46	710,7	362,01	21,884	1,981	4,024	2,001	3,929	-0,060	0,076																	
D16SE	2A	719,1	346,61	695,3	362,03	22,541	2,037	4,227	2,107	4,047	-0,139	0,172																	
D17ID	2A	722,8	349,56	685,7	364,76	21,215	1,998	3,945	2,011	3,788	-0,127	0,273																	
D17IE	2A	718,0	353,51	703,8	364,96	21,358	1,933	3,927	1,972	3,804	-0,060	0,154																	
D17SD	2A	713,3	351,02	709,7	365,17	20,909	1,905	3,872	1,914	3,722	-0,062	0,118																	
D17SE	2A	716,0	346,82	688,4	368,24	21,519	1,954	4,033	2,032	3,798	-0,121	0,301																	
D18ID	2A	720,6	347,81	686,1	362,12	21,117	1,905	3,946	2,001	3,790	-0,134	0,236																	
D18IE	2A	708,2	342,61	687,9	360,57	22,077	2,026	4,188	2,086	3,980	-0,126	0,203																	
D18SD	2A	713,7	350,46	695,1	358,62	21,254	1,936	3,942	1,987	3,852	-0,070	0,132																	
D18SE	2A	699,5	348,45	689,2	359,74	21,264	1,976	3,966	2,005	3,842	-0,015	0,183																	
D19ID	2A	725,0	351,35	716,3	363,01	21,883	1,982	4,048	1,986	3,918	-0,119	0,055																	
D19IE	2A	712,1	350,57	712,7	363,14	21,603	1,972	4,005	1,970	3,867	-0,061	0,078																	
D19SD	2A	727,6	355,94	717,7	365,71	21,940	1,960	4,007	1,987	3,900	-0,085	0,078																	
D19SE	2A	707,9	347,19	699,5	361,63	22,318	2,049	4,178	2,074	4,011	-0,075	0,141																	
D20ID	2A	721,1	354,53	704,8	366,72	21,987	1,982	4,031	2,028	3,897	-0,066	0,170																	
D20IE	2A	724,8	351,65	705,4	364,68	21,726	1,948	4,016	2,002	3,870	-0,115	0,143																	
D20SD	2A	721,3	355,93	708,5	369,27	22,067	1,986	4,030	2,025	3,884	-0,052	0,177																	
D20SE	2A	725,0	357,25	703,1	362,06	22,616	2,028	4,115	2,091	4,060	-0,057	0,123																	
D011B	4A	1293,3	630,3	1402,2	620,6	20,400	1,027	2,108	0,948	2,141	-0,049	-0,206	1	1,037	2,178	0,972	2,178	-0,091	-0,194										
D011E	4A	1261,7	605,2	1382,3	614,1	20,758	1,069	2,229	0,976	2,197	-0,078	-0,201	2	1,080	2,202	1,015</td													

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

POLY	DIE	POS	R1X	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	DELTA	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTAxDELTAy	
D02IE	4A	1244,7	620,8	1320,7	631,5	21,327	1,114	2,233	1,050	2,195	-0,005	-0,084	6	1,086	2,233	1,034	2,216	-0,053	-0,125
D02SD	4A	1292,9	628,3	1387,2	625,7	19,803	0,996	2,049	0,928	2,057	-0,055	-0,178	7	1,122	2,304	1,063	2,279	-0,051	-0,126
D02SE	4A	1217,B	616,2	1329,6	606,9	21,365	1,140	2,254	1,044	2,288	0,024	-0,160	8	1,107	2,220	1,032	2,212	-0,004	-0,124
D03ID	4A	1257,5	605,3	1333,9	610,5	20,953	1,083	2,230	1,021	2,231	-0,072	-0,156	9	1,147	2,311	1,076	2,296	-0,014	-0,118
D03IE	4A	1237,0	611,0	1307,2	609,5	20,152	1,059	2,144	1,002	2,149	-0,024	-0,126	10	1,110	2,274	1,058	2,231	-0,045	-0,097
D03SD	4A	1275,2	616,6	1338,0	616,8	20,775	1,059	2,190	1,009	2,189	-0,064	-0,145	11	1,102	2,229	1,041	2,189	-0,022	-0,092
D03SE	4A	1251,2	605,4	1322,9	616,3	21,311	1,107	2,288	1,047	2,248	-0,063	-0,128	12	1,133	2,320	1,087	2,295	-0,046	-0,099
D04ID	4A	1235,9	622,2	1354,0	618,1	21,985	1,138	2,297	1,055	2,312	-0,018	-0,160	13	1,120	2,276	1,075	2,272	-0,031	-0,101
D04IE	4A	1253,5	615,1	1338,9	618,2	21,475	1,114	2,269	1,043	2,258	-0,036	-0,142	14	1,092	2,270	1,048	2,243	-0,073	-0,123
D04SD	4A	1277,0	614,9	1354,8	618,5	22,570	1,149	2,386	1,083	2,372	-0,071	-0,160	15	1,090	2,238	1,018	2,199	-0,050	-0,138
D04SE	4A	1230,3	616,5	1306,2	620,8	22,272	1,177	2,348	1,108	2,332	0,004	-0,094	16	1,123	2,272	1,063	2,280	-0,022	-0,126
D05ID	4A	1260,6	609,2	1347,8	626,8	21,165	1,091	2,258	1,021	2,195	-0,065	-0,131	17	1,100	2,293	1,057	2,261	-0,077	-0,122
D5IE	4A	1250,6	620,3	1316,3	623,9	22,727	1,181	2,382	1,122	2,368	-0,016	-0,099	18	1,087	2,216	1,032	2,207	-0,038	-0,122
D05SD	4A	1315,5	624,4	1317,4	620,4	22,959	1,134	2,390	1,133	2,405	-0,097	-0,110	19	1,093	2,272	1,032	2,249	-0,072	-0,152
D05SE	4A	1226,5	615,7	1311,1	620,6	22,558	1,195	2,381	1,118	2,363	0,008	-0,101	20	1,117	2,279	1,064	2,242	-0,037	-0,097
D06ID	4A	1282,3	624,2	1347,7	629,7	21,384	1,084	2,227	1,031	2,207	-0,052	-0,123							
D06IE	4A	1250,6	622,8	1349,3	625,6	22,109	1,149	2,307	1,065	2,297	-0,008	-0,136							
D06SD	4A	1312,0	628,3	1358,6	630,5	21,135	1,047	2,186	1,011	2,179	-0,081	-0,134							
D06SE	4A	1294,1	622,9	1337,2	631,1	21,192	1,064	2,211	1,030	2,183	-0,072	-0,106							
D07ID	4A	1290,5	627,4	1376,0	631,9	22,209	1,119	2,301	1,049	2,285	-0,054	-0,151							
D07IE	4A	1276,9	626,3	1351,7	632,4	22,666	1,154	2,352	1,090	2,330	-0,037	-0,121							
D07SD	4A	1290,8	620,6	1358,1	638,7	21,727	1,094	2,276	1,040	2,211	-0,074	-0,112							
D07SE	4A	1286,3	629,9	1344,2	629,0	22,158	1,120	2,287	1,071	2,290	-0,040	-0,121							
D08ID	4A	1263,0	633,3	1363,9	638,0	20,368	1,048	2,090	0,971	2,075	0,006	-0,121							
D08IE	4A	1261,6	635,9	1369,5	632,7	22,197	1,144	2,267	1,054	2,280	0,016	-0,141							
D08SD	4A	1290,9	633,6	1362,9	636,3	22,497	1,133	2,308	1,073	2,298	-0,035	-0,124							
D08SE	4A	1271,2	634,1	1358,6	639,4	21,587	1,104	2,213	1,033	2,194	-0,005	-0,111							
D09ID	4A	1258,1	621,5	1377,0	637,6	22,408	1,158	2,344	1,058	2,284	-0,024	-0,138							
D09IE	4A	1252,0	627,0	1351,4	625,9	22,229	1,154	2,304	1,069	2,308	0,003	-0,137							
D09SD	4A	1285,8	638,6	1364,6	637,4	22,472	1,136	2,287	1,070	2,292	-0,013	-0,123							
D09SE	4A	1294,3	639,9	1334,6	642,4	22,740	1,142	2,310	1,107	2,301	-0,022	-0,072							
D10ID	4A	1316,8	623,1	1407,5	644,6	22,261	1,099	2,322	1,028	2,245	-0,102	-0,155							
D10IE	4A	1301,9	637,0	1356,9	647,2	21,435	1,070	2,187	1,027	2,153	-0,042	-0,088							
D10SD	4A	1298,6	642,7	1348,3	646,8	22,488	1,126	2,274	1,084	2,260	-0,020	-0,078							
D10SE	4A	1282,4	635,7	1343,3	649,1	22,623	1,147	2,313	1,095	2,265	-0,017	-0,065							
D11ID	4A	1259,6	622,63	1381,8	642,63	21,343	1,101	2,228	1,004	2,159	-0,023	-0,131							
D11IE	4A	1266,5	643,14	1355,1	645,45	21,247	1,090	2,147	1,019	2,139	0,032	-0,090							
D11SD	4A	1297,4	636,87	1360,3	643,12	23,104	1,157	2,358	1,104	2,335	-0,036	-0,103							
D11SE	4A	1306,4	632,86	1331,2	650,49	21,269	1,058	2,185	1,039	2,125	-0,060	-0,044							
D12ID	4A	1288,2	628,20	1341,8	624,41	22,262	1,125	2,303	1,078	2,317	-0,045	-0,130							
D12IE	4A	1254,4	612,74	1331,8	646,10	22,682	1,175	2,406	1,107	2,282	-0,045	-0,058							
D12SD	4A	1288,3	630,23	1328,3	624,58	22,418	1,131	2,312	1,097	2,333	-0,042	-0,112							
D12SE	4A	1294,8	630,10	1333,7	633,38	21,900	1,099	2,259	1,067	2,247	-0,052	-0,096							
D13ID	4A	1284,4	630,99	1355,3	625,29	22,749	1,151	2,343	1,091	2,365	-0,034	-0,143							
D13IE	4A	1271,9	630,09	1331,1	635,45	22,083	1,128	2,278	1,078	2,259	-0,018	-0,086							
D13SD	4A	1275,8	634,13	1320,3	629,23	21,352	1,088	2,189	1,051	2,206	-0,012	-0,089							
D13SE	4A	1291,0	626,09	1330,1	635,78	22,093	1,112	2,294	1,080	2,258	-0,058	-0,084							
D14ID	4A	1298,1	623,32	1394,9	635,67	22,269	1,115	2,322	1,038	2,277	-0,076	-0,163							
D14IE	4A	1297,2	625,91	1352,3	638,02	21,198	1,062	2,201	1,019	2,166	-0,068	-0,112							
D14SD	4A	1307,9	635,87	1346,7	635,56	22,893	1,138	2,340	1,105	2,341	-0,054	-0,106							
D14SE	4A	1320,6	627,66	1353,2	638,77	21,412	1,054	2,217	1,029	2,186	-0,094	-0,111							
D15ID	4A	1294,8	626,51	1396,4	639,91	22,194	1,114	2,303	1,033	2,254	-0,063	-0,154							
D15IE	4A	1278,5	627,48	1379,7	639,18	21,919	1,114	2,271	1,033	2,229	-0,036	-0,137							
D15SD	4A	1298,7	635,37	1378,7	636,61	20,776	1,040	2,125	0,979	2,121	-0,042	-0,142							
D15SE	4A	1298,7	628,84	1381,2	646,78	21,795	1,091	2,253	1,026	2,190	-0,061	-0,119							

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

POLY	DIE	POS	R1X	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	DELTA	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	XDELTA	YDELTA
B09SE	SA	1322,6	631,1	1281,0	626,2	22,902	1,126	2,359	1,162	2,377	-0,087	-0,044								
D101D	SA	1353,1	631,8	1271,7	619,3	19,884	0,755	2,046	1,016	2,087	-0,124	-0,051								
D101E	SA	1355,9	645,4	1293,9	635,6	22,478	1,078	2,264	1,129	2,299	-0,092	-0,034								
D105D	SA	1284,7	649,2	1274,8	611,7	22,783	1,153	2,281	1,162	2,421	0,022	-0,078								
D105E	SA	1335,0	635,6	1276,1	623,0	21,997	1,071	2,249	1,120	2,295	-0,091	-0,046								
D111D	SA	1340,7	644,23	1257,4	619,13	21,899	1,042	2,209	1,132	2,299	-0,075	-0,030								
D111E	SA	1328,9	647,47	1269,1	630,66	22,565	1,104	2,265	1,156	2,326	-0,050	-0,012								
D115D	SA	1319,6	650,04	1250,4	617,35	23,420	1,154	2,342	1,217	2,466	-0,029	-0,025								
D115E	SA	1351,9	646,14	1285,5	620,61	22,333	1,074	2,247	1,129	2,339	-0,084	-0,067								
D121D	SA	1307,3	632,45	1237,9	601,81	21,329	1,060	2,192	1,120	2,304	-0,063	-0,054								
D121E	SA	1335,9	652,49	1268,7	619,72	21,882	1,065	2,180	1,121	2,295	-0,045	-0,045								
D125D	SA	1263,8	642,22	1223,4	608,22	22,652	1,165	2,273	1,203	2,421	0,033	-0,011								
D125E	SA	1336,6	657,63	1243,9	622,59	21,696	1,055	2,144	1,134	2,265	-0,031	0,002								
D131D	SA	1357,2	633,75	1220,6	604,36	20,879	1,000	2,141	1,112	2,246	-0,124	-0,019								
D131E	SA	1325,8	648,48	1264,5	625,56	22,982	1,127	2,304	1,181	2,388	-0,043	-0,021								
D135D	SA	1287,2	638,95	1232,2	605,50	20,718	1,046	2,108	1,093	2,224	-0,014	-0,034								
D135E	SA	1334,5	631,32	1280,0	618,24	22,135	1,078	2,279	1,124	2,327	-0,102	-0,066								
D141D	SA	1334,5	648,88	1238,6	609,48	22,552	1,098	2,259	1,183	2,404	-0,054	-0,031								
D141E	SA	1333,3	637,11	1289,6	624,16	21,841	1,065	2,228	1,101	2,267	-0,085	-0,056								
D145D	SA	1304,5	642,08	1249,3	606,67	22,931	1,143	2,251	1,193	2,457	0,031	-0,056								
D145E	SA	1319,7	646,54	1300,1	623,79	21,900	1,079	2,202	1,095	2,282	-0,039	-0,078								
D151D	SA	1321,7	632,67	1272,0	620,04	23,452	1,153	2,409	1,198	2,458	-0,082	-0,049								
D151E	SA	1363,3	644,74	1303,9	629,22	21,311	1,016	2,148	1,062	2,201	-0,103	-0,067								
D155B	SA	1300,8	654,97	1251,8	603,67	22,721	1,135	2,255	1,180	2,446	0,014	-0,069								
D155E	SA	1344,6	639,14	1257,8	625,04	22,635	1,094	2,306	1,170	2,354	-0,097	-0,012								
D161D	SA	1326,1	635,06	1254,9	614,10	22,149	1,086	2,267	1,147	2,344	-0,081	-0,042								
D161E	SA	1358,7	658,90	1300,4	636,07	22,985	1,100	2,267	1,149	2,349	-0,058	-0,043								
D165D	SA	1300,6	655,65	1240,0	612,22	23,066	1,153	2,287	1,209	2,449	0,017	-0,025								
D165E	SA	1348,2	645,39	1288,1	636,40	22,193	1,054	2,235	1,120	2,267	-0,107	-0,024								
D171D	SA	1325,8	639,44	1250,8	611,96	21,090	1,034	2,144	1,096	2,240	-0,068	-0,042								
D171E	SA	1340,7	633,35	1276,1	638,94	20,791	1,008	2,134	1,059	2,115	-0,105	0,003								
D175D	SA	1310,2	672,48	1241,5	618,64	22,576	1,120	2,182	1,182	2,372	0,055	-0,007								
D175E	SA	1334,9	645,09	1309,7	623,43	22,996	1,120	2,317	1,141	2,398	-0,065	-0,092								
D181D	SA	1321,2	641,23	1267,1	616,55	22,273	1,094	2,258	1,143	2,348	-0,057	-0,052								
D181E	SA	1324,0	635,04	1301,4	622,35	22,858	1,122	2,340	1,142	2,387	-0,078	-0,083								
D185D	SA	1266,6	649,89	1259,6	609,66	22,462	1,153	2,247	1,159	2,395	0,054	-0,062								
D185E	SA	1330,6	644,06	1268,0	630,65	22,425	1,094	2,243	1,159	2,311	-0,061	0,005								
D191D	SA	1325,8	638,81	1254,7	625,85	22,558	1,104	2,295	1,169	2,343	-0,070	-0,005								
D191E	SA	1333,0	655,19	1297,6	642,48	22,996	1,121	2,281	1,152	2,327	-0,033	-0,019								
D195D	SA	1401,9	643,37	1254,6	609,14	23,393	1,085	2,363	1,212	2,496	-0,152	-0,056								
D195E	SA	1351,8	648,21	1280,4	624,08	20,787	0,999	2,084	1,055	2,165	-0,079	-0,049								
D201D	SA	1335,6	632,57	1244,2	630,81	22,094	1,075	2,201	1,154	2,277	-0,045	0,028	6A							
D201E	SA	1375,0	642,15	1293,2	642,55	23,096	1,092	2,338	1,161	2,336	-0,124	-0,012								
D205D	SA	1305,0	635,56	1263,3	626,94	23,324	1,162	2,313	1,200	2,418	0,009	-0,015								
D205E	SA	1361,3	656,31	1292,5	638,27	22,309	1,065	2,209	1,122	2,272	-0,069	-0,024								
D211D	SA	623,4	314,7	605,1	310,3	20,619	2,150	4,259	2,215	4,319	0,039	0,105	1	2,123	4,241	2,201	4,283	0,007	0,115	
D211E	SA	620,7	316,6	603,6	307,1	20,273	2,123	4,162	2,183	4,291	0,082	0,072	2	2,105	4,173	2,189	4,210	0,037	0,167	
D215D	SA	627,5	315,2	599,3	312,5	20,431	2,116	4,213	2,216	4,250	0,019	0,179	3	2,165	4,337	2,276	4,411	-0,007	0,132	
D215E	SA	631,4	306,5	606,5	310,9	20,426	2,103	4,332	2,189	4,270	-0,113	0,104	4	2,140	4,209	2,224	4,239	0,069	0,208	
D221D	SA	626,2	317,9	601,6	312,7	19,832	2,059	4,055	2,143	4,122	0,062	0,165	5	2,179	4,346	2,241	4,340	0,012	0,135	
D221E	SA	640,8	317,2	608,4	316,0	20,058	2,035	4,110	2,143	4,126	-0,040	0,161	6	2,150	4,263	2,239	4,279	0,036	0,195	
D225D	SA	626,3	321,3	609,8	316,0	20,341	2,111	4,115	2,168	4,184	0,107	0,151	7	2,129	4,205	2,225	4,237	0,052	0,212	
D225E	SA	620,0	311,3	596,0	311,5	21,124	2,215	4,411	2,304	4,408	0,017	0,190	8	2,162	4,265	2,227	4,285	0,056	0,165	
D231D	SA	639,3	316,3	608,0	314,1	20,996	2,135	4,315	2,245	4,345	-0,041	0,137	9	2,188	4,294	2,290	4,315	0,080	0,261	
D231E	SA	628,8	315,7	599,8	312,3	20,875	2,158	4,298	2,262	4,345	0,017	0,173	10	2,148	4,298	2,237	4,285	-0,001	0,184	

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

POLY																			
DIE	POS	R1X	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	DELTA	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	XDELTA	YDELTA
D17IE	6A	661,7	333,52	631,4	337,54	22,104	2,171	4,308	2,275	4,256	0,033	0,297							
D17SD	6A	637,8	334,10	625,0	329,93	21,482	2,189	4,179	2,234	4,232	0,200	0,236							
D17SE	6A	658,8	327,09	632,9	336,39	22,173	2,188	4,406	2,277	4,284	-0,028	0,269							
D18ID	6A	644,5	327,96	626,7	332,92	21,321	2,150	4,226	2,211	4,163	0,072	0,267							
D18IC	6A	649,1	333,99	630,2	331,66	21,535	2,157	4,191	2,221	4,220	0,120	0,222							
D18SD	6A	649,5	329,06	635,0	335,74	21,494	2,151	4,246	2,200	4,161	0,054	0,244							
D18SE	6A	654,4	323,88	622,6	330,51	21,669	2,132	4,349	2,262	4,262	-0,040	0,243							
D19ID	6A	664,1	329,58	628,0	333,27	21,743	2,128	4,288	2,250	4,241	-0,029	0,261							
D19IE	6A	665,6	331,96	627,9	331,53	22,137	2,162	4,335	2,292	4,340	-0,010	0,237							
D19SD	6A	658,6	331,47	634,3	334,20	22,117	2,183	4,337	2,266	4,302	0,026	0,227							
D19SE	6A	659,3	338,03	619,7	336,37	21,966	2,165	4,224	2,304	4,245	0,104	0,375							
D20ID	6A	663,6	336,38	634,8	334,64	21,643	2,120	4,182	2,216	4,204	0,056	0,230							
D20IE	6A	668,0	335,06	631,9	337,60	21,682	2,110	4,206	2,230	4,175	0,013	0,295							
D20SD	6A	650,7	337,28	635,6	335,68	21,872	2,185	4,215	2,237	4,235	0,152	0,238							
D20SE	6A	661,4	332,47	629,9	336,77	21,778	2,140	4,258	2,247	4,203	0,022	0,298							

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

14

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	R1X	POLY	COLUMA DA ESQUERDA	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	DELTA	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTAxDELTAy
E14SE	1A	1644,3	715,0	1615,8	734,7	22,790	0,901	2,072	0,917	2,016	-0,231	-0,166							
E15ID	1A	1625,2	711,2	1623,6	720,9	21,911	0,876	2,003	0,877	1,976	-0,222	-0,201							
E15IE	1A	1687,3	710,9	1641,0	734,1	23,063	0,888	2,109	0,914	2,042	-0,272	-0,191							
E15SD	1A	1647,2	716,8	1625,3	730,9	23,397	0,923	2,122	0,936	2,081	-0,230	-0,183							
E15SE	1A	1697,1	711,2	1619,0	729,3	21,577	0,826	1,972	0,866	1,923	-0,279	-0,180							
E16ID	1A	1635,6	713,7	1608,7	730,0	23,900	0,738	2,177	0,966	2,128	-0,242	-0,169							
E16IE	1A	1700,1	701,8	1606,7	730,1	22,621	0,865	2,095	0,915	2,014	-0,297	-0,167							
E16SD	1A	1677,0	716,7	1606,8	744,3	23,183	0,899	2,103	0,938	2,025	-0,254	-0,137							
E16SE	1A	1698,8	718,4	1604,7	728,6	23,276	0,891	2,105	0,943	2,077	-0,267	-0,168							
E17ID	1A	1667,9	725,3	1643,0	735,5	23,700	0,924	2,124	0,938	2,094	-0,231	-0,190							
E17IE	1A	1712,3	719,1	1626,2	737,8	22,986	0,873	2,078	0,919	2,025	-0,276	-0,170							
E17SD	1A	1689,0	727,7	1658,6	746,8	22,972	0,884	2,052	0,900	1,999	-0,243	-0,181							
E17SE	1A	1714,5	715,1	1681,8	742,6	23,890	0,906	2,172	0,923	2,091	-0,284	-0,209							
E18ID	1A	1667,5	716,5	1596,1	736,3	22,980	0,896	2,085	0,936	2,029	-0,247	-0,144							
E18IE	1A	1678,0	728,1	1632,0	737,1	23,246	0,900	2,075	0,926	2,050	-0,233	-0,176							
E18SD	1A	1685,7	726,0	1619,6	735,5	22,229	0,857	1,990	0,892	1,964	-0,244	-0,168							
E18SE	1A	1669,5	742,0	1654,5	747,2	22,248	0,866	1,949	0,874	1,935	-0,200	-0,176							
E19ID	1A	1621,0	717,7	1582,3	729,5	23,599	0,946	2,137	0,969	2,103	-0,205	-0,145							
E19IE	1A	1684,9	698,7	1614,1	733,4	22,323	0,861	2,077	0,899	1,978	-0,292	-0,167							
E19SD	1A	1661,9	716,0	1597,7	724,3	22,839	0,893	2,073	0,929	2,050	-0,243	-0,171							
E19SE	1A	1695,8	728,1	1613,8	735,9	23,237	0,891	2,074	0,936	2,052	-0,248	-0,162							
E20ID	1A	1630,6	716,1	1614,4	733,0	22,133	0,882	2,009	0,891	1,963	-0,217	-0,168							2A
E20IE	1A	1659,3	717,0	1611,7	733,3	23,039	0,902	2,089	0,929	2,042	-0,239	-0,165							
E20SD	1A	1662,0	726,6	1692,4	732,8	23,507	0,919	2,103	0,903	2,085	-0,223	-0,236							
E20SE	1A	1667,5	714,8	1647,4	735,2	22,800	0,889	2,073	0,900	2,018	-0,250	-0,194							
E01ID	2A	685,4	334,0	667,3	344,0	20,881	1,980	4,064	2,034	3,946	-0,099	0,128	1	1,911	3,986	1,975	3,869	-0,159	0,084
E01IE	2A	686,2	333,7	670,3	343,2	20,872	1,977	4,065	2,024	3,953	-0,107	0,098	2	1,944	4,016	2,015	3,890	-0,123	0,149
E01SD	2A	714,3	331,6	685,0	343,9	19,763	1,798	3,874	1,875	3,735	-0,267	0,016	3	1,955	4,015	1,994	3,878	-0,102	0,118
E01SE	2A	703,0	336,5	674,8	345,1	20,407	1,887	3,942	1,941	3,844	-0,164	0,093	4	1,978	4,040	2,031	3,932	-0,082	0,139
E02ID	2A	686,2	335,4	676,8	346,6	21,492	2,036	4,165	2,064	4,030	-0,088	0,099	5	1,988	4,060	2,028	3,905	-0,082	0,162
E02IE	2A	687,2	335,1	658,4	342,4	20,349	1,925	3,947	2,009	3,863	-0,097	0,167	6	1,939	3,995	1,995	3,852	-0,114	0,148
E02SD	2A	693,0	334,8	664,0	345,4	21,173	1,986	4,111	2,073	3,984	-0,131	0,168	7	1,987	4,021	2,009	3,873	-0,045	0,155
E02SE	2A	695,4	331,5	665,7	345,9	19,587	1,831	3,840	1,912	3,681	-0,178	0,163	8	1,967	4,016	2,027	3,884	-0,079	0,184
E03ID	2A	686,4	335,2	671,6	347,1	20,663	1,957	4,007	2,000	3,869	-0,091	0,139	9	1,983	4,045	2,036	3,909	-0,075	0,173
E03IE	2A	691,1	336,2	672,7	347,1	20,387	1,936	3,980	1,989	3,855	-0,105	0,132	10	2,013	4,100	2,044	3,960	-0,070	0,135
E03SD	2A	687,5	332,4	677,4	346,5	20,261	1,916	3,962	1,944	3,801	-0,128	0,094	11	2,011	4,078	2,050	3,939	-0,054	0,170
E03SE	2A	687,2	336,1	676,2	346,8	21,264	2,011	4,112	2,044	3,985	-0,085	0,106	12	2,018	4,063	2,050	3,889	-0,027	0,230
E04ID	2A	693,2	342,3	671,7	346,2	20,969	1,966	3,982	2,029	3,937	-0,049	0,127	13	2,028	4,110	2,073	3,967	-0,050	0,190
E04IE	2A	689,3	338,8	644,5	347,3	20,308	1,915	3,954	1,992	3,801	-0,122	0,204	14	2,003	4,096	2,049	3,941	-0,086	0,167
E04SD	2A	682,6	332,0	675,3	346,4	21,245	2,023	4,159	2,045	3,986	-0,106	0,106	15	2,014	4,105	2,067	3,950	-0,072	0,196
E04SE	2A	691,4	341,4	673,8	346,6	21,346	2,007	4,064	2,059	4,003	-0,049	0,119	16	2,024	4,090	2,075	3,978	-0,037	0,182
E05ID	2A	703,1	341,0	679,1	351,9	21,098	1,950	4,022	2,019	3,897	-0,117	0,151	17	2,016	4,161	2,073	3,966	-0,120	0,191
E05IE	2A	680,9	336,2	683,2	357,5	21,142	2,018	4,087	2,011	3,844	-0,049	0,195	18	1,986	4,034	2,043	3,928	-0,059	0,169
E05SD	2A	701,9	343,7	678,2	350,2	21,353	1,977	4,038	2,047	3,943	-0,081	0,135	19	2,028	4,072	2,035	3,918	-0,015	0,161
E05SE	2A	691,0	338,5	680,0	353,5	21,307	2,004	4,091	2,037	3,918	-0,079	0,165	20	2,008	4,074	2,058	3,939	-0,056	0,188
E06ID	2A	696,3	341,1	686,1	357,1	21,065	1,966	4,014	1,996	3,834	-0,079	0,171							
E06IE	2A	701,9	342,5	686,9	354,0	20,953	1,940	3,976	1,983	3,847	-0,094	0,127		1,990	4,059	2,036	3,918	-0,075	0,165
E06SD	2A	708,6	339,5	675,1	353,6	21,229	1,947	4,064	2,044	3,902	-0,160	0,200		0,032	0,043	0,027	0,036	0,035	0,031
E06SE	2A	710,7	344,2	690,8	353,3	20,788	1,901	3,924	1,956	3,822	-0,122	0,076							
E07ID	2A	702,8	343,8	680,4	357,2	21,161	1,957	4,001	2,022	3,851	-0,085	0,210							
E07IE	2A	693,9	348,6	682,7	356,4	21,336	1,999	3,978	2,031	3,891	-0,019	0,184							
E07SD	2A	702,2	342,3	700,2	358,6	21,352	1,976	4,054	1,982	3,870	-0,098	0,100							
E07SE	2A	692,2	344,6	698,1	359,8	21,485	2,017	4,053	2,000	3,881	-0,017	0,127							
E08ID	2A	722,1	347,8	694,9	362,0	21,744	1,957	4,064	2,034	3,904	-0,142	0,175							
E08IE	2A	712,5	348,8	687,4	363,3	21,909	1,999	4,083	2,072	3,920	-0,082	0,242							

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	RIX	POLY COLUNA DA ESQUERDA										LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	XDELTA	YDELTA
			R2X	R1Y	R2Y	RS	LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	DELTA							
E08SD	2A	718,8	349,7	689,1	357,5	21,097	1,908	3,921	1,990	3,836	-0,105	0,156							
E08SE	2A	701,1	351,6	697,4	362,3	21,608	2,003	3,995	2,014	3,877	0,012	0,162							
E091D	2A	724,4	354,1	706,2	362,6	22,020	1,976	4,042	2,027	3,947	-0,087	0,111							
E091E	2A	711,3	355,4	695,0	343,7	20,987	1,918	3,838	1,963	3,751	-0,003	0,196							
E095D	2A	718,9	351,2	697,4	364,9	22,495	2,034	4,163	2,097	4,007	-0,090	0,195							
E095E	2A	713,4	345,8	695,5	343,7	22,001	2,005	4,135	2,056	3,932	-0,119	0,192							
E101D	2A	722,9	349,3	700,4	366,0	21,783	1,959	4,054	2,022	3,869	-0,130	0,189							
E101E	2A	723,1	353,7	714,5	365,4	22,636	2,035	4,160	2,059	4,027	-0,085	0,093							
E105D	2A	712,8	332,8	707,2	343,8	22,537	2,055	4,152	2,071	4,027	-0,040	0,119							
E105E	2A	709,4	332,5	702,7	343,1	21,881	2,005	4,035	2,024	3,917	-0,025	0,138							
E111D	2A	722,2	351,4	689,2	362,1	22,157	1,994	4,098	2,090	3,977	-0,105	0,214							
E111E	2A	713,9	355,5	711,7	366,3	22,418	2,041	4,099	2,047	3,978	-0,016	0,121							
E115D	2A	706,3	348,0	699,8	363,7	21,253	1,956	3,970	1,974	3,798	-0,057	0,164							
E115E	2A	713,4	333,4	701,7	346,0	22,543	2,054	4,146	2,088	4,003	-0,037	0,181							
E121D	2A	692,0	344,6	700,0	365,1	21,901	2,057	4,131	2,034	3,899	-0,016	0,180							
E121E	2A	702,7	349,3	681,4	364,1	22,432	2,075	4,174	2,140	4,005	-0,023	0,295							
E125D	2A	706,9	350,2	691,6	368,3	21,787	2,003	4,044	2,048	3,845	-0,036	0,278							
E125E	2A	716,5	355,5	700,9	364,3	21,344	1,936	3,903	1,979	3,808	-0,030	0,165							
E131D	2A	702,4	346,5	692,7	362,0	22,084	2,042	4,139	2,070	3,962	-0,053	0,189							
E131E	2A	704,4	349,6	693,7	360,2	22,186	2,047	4,125	2,079	4,004	-0,029	0,160							
E135D	2A	705,6	349,6	682,5	362,4	21,976	2,024	4,086	2,093	3,942	-0,036	0,264							
E135E	2A	714,2	349,8	697,9	361,2	22,001	2,002	4,088	2,049	3,959	-0,080	0,146							
E141D	2A	705,2	346,4	690,8	357,4	21,806	2,010	4,092	2,052	3,966	-0,069	0,144							
E141E	2A	699,7	342,8	679,9	358,6	21,357	2,003	4,087	2,061	3,907	-0,079	0,232							
E145D	2A	705,3	345,3	694,8	356,5	21,158	1,950	3,983	1,979	3,858	-0,082	0,108							
E145E	2A	710,5	344,7	691,0	360,6	22,384	2,048	4,221	2,104	4,035	-0,115	0,183							
E151D	2A	696,4	347,4	696,7	363,2	20,598	1,923	3,854	1,922	3,686	-0,009	0,178							
E151E	2A	708,6	348,4	687,6	364,2	22,257	2,042	4,152	2,104	3,972	-0,066	0,252							
E155D	2A	717,8	349,2	692,8	362,7	22,124	2,003	4,118	2,074	3,965	-0,105	0,198							
E155E	2A	715,6	347,8	689,9	357,8	22,989	2,088	4,296	2,166	4,176	-0,109	0,155							
E161D	2A	725,5	360,0	695,5	367,0	22,847	2,047	4,125	2,135	4,046	-0,030	0,234							
E161E	2A	709,9	352,4	701,9	361,3	22,070	2,021	4,071	2,044	3,971	-0,029	0,122							
E165D	2A	715,9	351,6	699,9	364,1	22,151	2,011	4,095	2,057	3,954	-0,070	0,169							
E165E	2A	705,3	350,9	690,9	362,3	21,957	2,024	4,067	2,064	3,939	-0,020	0,205							
E171D	2A	712,3	340,0	697,4	341,8	21,894	1,998	4,186	2,041	3,934	-0,174	0,156							
E171E	2A	719,5	353,7	694,4	369,0	22,361	2,020	4,109	2,093	3,939	-0,066	0,268							
E175D	2A	722,0	348,5	708,3	366,8	22,749	2,048	4,243	2,088	4,031	-0,134	0,148							
E175E	2A	723,5	351,9	697,8	364,7	22,223	1,997	4,105	2,070	3,961	-0,104	0,190							
E181D	2A	720,5	351,2	701,0	369,3	22,059	1,990	4,083	2,045	3,883	-0,098	0,227							
E181E	2A	727,4	356,4	704,3	365,2	22,249	1,988	4,058	2,053	3,960	-0,079	0,154							
E185D	2A	719,1	352,3	715,7	369,3	21,965	1,985	4,053	1,995	3,866	-0,079	0,132							
E185E	2A	729,7	366,5	694,5	361,0	22,226	1,980	3,942	2,080	4,002	0,018	0,165							
E191D	2A	718,5	351,3	706,2	363,9	21,606	1,955	3,998	1,989	3,859	-0,087	0,126							
E191E	2A	688,5	348,7	692,1	360,8	21,828	2,061	4,069	2,050	3,932	0,052	0,178							
E195D	2A	694,4	349,8	695,1	363,4	22,395	2,096	4,161	2,094	4,006	0,030	0,191							
E195E	2A	707,8	348,7	705,6	365,3	21,782	2,000	4,060	2,007	3,876	-0,058	0,147							
E201D	2A	713,6	352,3	697,3	364,4	21,802	1,986	4,023	2,032	3,889	-0,050	0,189							
E201E	2A	716,0	353,5	684,8	364,2	22,284	2,023	4,097	2,115	3,977	-0,050	0,272							
E205D	2A	720,7	349,0	701,2	362,1	21,939	1,979	4,086	2,034	3,938	-0,122	0,136	LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	XDELTA	
E205E	2A	708,3	353,9	706,1	366,2	22,272	2,044	4,091	2,050	3,953	-0,003	0,153							
E011R	4A	1272,4	623,7	1379,6	615,7	20,363	1,040	2,122	0,959	2,150	-0,039	-0,194	1	1,066	2,183	1,004	2,188	-0,046	-0,152
E011E	4A	1256,4	620,0	1328,2	615,2	20,675	1,068	2,167	1,012	2,184	-0,029	-0,137	2	1,087	2,183	1,016	2,190	-0,008	-0,135
E015D	4A	1276,0	622,8	1360,8	623,5	19,932	1,016	2,082	0,953	2,080	-0,047	-0,154	3	1,060	2,178	0,995	2,151	-0,050	-0,138
E015E	4A	1295,3	624,3	1348,2	630,1	22,673	1,138	2,361	1,093	2,339	-0,070	-0,123	4	1,126	2,284	1,058	2,266	-0,028	-0,123
E021D	4A	1250,6	611,4	1343,5	619,2	21,531	1,119	2,289	1,042	2,260	-0,043	-0,145	5	1,134	2,307	1,066	2,277	-0,033	-0,120

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA DE PÓLIMA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE TOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA DE TOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	R1X	POLY COLUNA DA ESQUERDA												LNW1X	LNW2X	LNW1Y	LNW2Y	DELTANXDELTY
			R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA	DELTA							
E09SE	5A	1353,3	656,4	1315,2	629,1	23.435	1,126	2.321	1,158	2,421	-0,058	-0,083							
E10ID	5A	1324,0	664,1	1267,3	630,0	21.994	1,080	2.153	1,128	2,269	0,006	-0,011							
E10IB	5A	1387,4	656,0	1316,0	649,5	22.742	1,065	2,253	1,123	2,276	-0,103	-0,026							
E10SD	5A	1358,6	652,1	1281,2	624,0	22.065	1,056	2,199	1,119	2,298	-0,077	-0,051							
E10SE	5A	1347,2	673,3	1291,8	638,0	23.664	1,142	2,285	1,191	2,411	-0,001	-0,024							
E11ID	5A	1354,5	634,9	1290,2	626,3	21.373	1,026	2,089	1,077	2,218	-0,036	-0,057							
E11IR	5A	1371,7	658,6	1281,7	634,9	23.179	1,098	2,288	1,176	2,373	-0,076	-0,018							
E11SD	5A	1352,9	660,3	1292,0	630,7	22.050	1,059	2,171	1,109	2,272	-0,047	-0,046							
E11SE	5A	1350,4	662,8	1302,8	627,8	22.842	1,099	2,240	1,140	2,365	-0,036	-0,070							
E12ID	5A	1346,3	642,6	1296,6	624,7	22.755	1,099	2,302	1,141	2,368	-0,087	-0,070							
E12IE	5A	1360,1	663,8	1302,1	631,4	21.806	1,042	2,135	1,089	2,245	-0,047	-0,059							
E12SD	5A	1358,6	636,6	1252,6	615,2	22.345	1,070	2,282	1,159	2,361	-0,118	-0,035							
E12SE	5A	1328,4	659,9	1299,4	634,7	22.284	1,090	2,195	1,115	2,282	-0,013	-0,045							
E13ID	5A	1355,4	645,8	1254,8	622,0	21.515	1,032	2,165	1,114	2,248	-0,090	-0,017							
E13IE	5A	1349,7	638,0	1259,7	632,1	23.415	1,128	2,396	1,208	2,408	-0,104	0,007							
E13SD	5A	1359,8	635,4	1259,7	626,8	21.933	1,048	2,244	1,132	2,274	-0,123	-0,010							
E13SE	5A	1341,1	663,9	1298,2	638,0	22.450	1,098	2,218	1,134	2,308	-0,020	-0,034							
E14ID	5A	1357,2	649,4	1223,4	613,9	22.811	1,092	2,373	1,212	2,415	-0,147	0,007							
E14IE	5A	1353,5	635,2	1285,1	625,4	22.581	1,084	2,311	1,142	2,347	-0,116	-0,052							
E14SD	5A	1303,5	643,9	1255,0	610,9	22.541	1,124	2,275	1,167	2,398	-0,024	-0,052							
E14SE	5A	1301,9	645,2	1285,1	639,8	22.888	1,143	2,306	1,158	2,325	-0,018	-0,009							
E15ID	5A	1346,5	643,9	1253,7	625,1	21.861	1,055	2,207	1,133	2,273	-0,084	-0,006							
E15IE	5A	1349,5	648,6	1285,0	632,2	23.129	1,114	2,317	1,170	2,378	-0,074	-0,032							
E15SD	5A	1336,9	645,4	1265,6	609,1	23.254	1,131	2,342	1,194	2,482	-0,047	-0,072							
E15SE	5A	1308,9	650,6	1292,3	633,2	22.407	1,113	2,239	1,127	2,300	-0,012	-0,039							
E16ID	5A	1344,4	644,7	1282,7	626,4	22.550	1,090	2,274	1,161	2,340	-0,079	-0,016							
E16IE	5A	1359,3	643,9	1299,0	636,8	21.169	1,012	2,137	1,059	2,161	-0,100	-0,038							
E16SD	5A	1330,0	645,3	1248,2	620,8	22.294	1,090	2,246	1,161	2,334	-0,058	-0,011							
E16SE	5A	1330,4	655,6	1300,3	636,4	22.777	1,113	2,258	1,139	2,348	-0,028	-0,059							
E17ID	5A	1356,4	649,8	1285,0	633,6	22.971	1,101	2,298	1,162	2,357	-0,080	-0,027							
E17IE	5A	1354,4	644,1	1291,9	644,9	22.357	1,073	2,256	1,125	2,246	-0,093	0,003							
E17SD	5A	1378,9	643,9	1286,7	628,7	23.707	1,127	2,413	1,213	2,472	-0,124	-0,036							
E17SE	5A	1359,9	640,8	1318,6	637,4	24.036	1,149	2,438	1,185	2,451	-0,109	-0,064							
E18ID	5A	1343,9	656,4	1252,0	628,6	22.958	1,110	2,273	1,192	2,374	-0,045	0,008							
E18IE	5A	1354,8	652,1	1283,2	644,4	23.300	1,118	2,322	1,180	2,350	-0,072	0,009							
E18SD	5A	1330,2	643,0	1245,5	620,0	22.349	1,092	2,259	1,148	2,313	-0,064	-0,014							
E18SE	5A	1324,9	654,8	1274,9	632,2	23.847	1,131	2,281	1,175	2,370	-0,017	-0,016							
E19ID	5A	1331,4	645,5	1262,9	618,9	20.754	1,023	2,110	1,078	2,201	-0,059	-0,039							
E19IE	5A	1357,0	659,1	1291,9	634,3	23.151	1,109	2,283	1,165	2,372	-0,056	-0,035							
E19SD	5A	1306,1	641,3	1270,3	620,5	20.818	1,036	2,110	1,065	2,181	-0,035	-0,045							
E19SE	5A	1321,5	649,7	1281,4	635,0	21.148	1,040	2,116	1,073	2,165	-0,033	-0,018							
E20ID	5A	1362,8	652,5	1275,2	628,5	22.096	1,054	2,201	1,126	2,285	-0,081	-0,028						6A	
E20IE	5A	1320,2	643,7	1311,3	634,9	22.050	1,086	2,227	1,093	2,257	-0,048	-0,061							
E20SD	5A	1336,5	648,8	1286,4	630,9	23.431	1,140	2,347	1,184	2,414	-0,057	-0,038		LNW1X	LNW2X	LNW1Y	LNW2Y	DELTANXDELTY	
E20SE	5A	1335,2	659,6	1304,1	647,8	23.286	1,134	2,295	1,161	2,336	-0,024	-0,013							
E01ID	6A	635,9	314,1	614,5	316,4	20.553	2,101	4,253	2,174	4,222	-0,048	0,123	1	2,099	4,173	2,174	4,194	0,025	0,153
E01IE	6A	634,5	319,1	609,4	315,7	20.196	2,069	4,114	2,154	4,158	0,023	0,150	2	2,087	4,147	2,151	4,192	0,024	0,107
E01SD	6A	626,3	320,3	606,8	315,5	20.369	2,114	4,133	2,182	4,196	0,093	0,166	3	2,159	4,243	2,221	4,289	0,072	0,148
E01SE	6A	626,3	315,7	604,9	315,1	20.359	2,113	4,192	2,188	4,200	0,033	0,175	4	2,088	4,125	2,163	4,158	0,052	0,169
E02ID	6A	642,2	318,8	618,8	314,0	19.765	2,001	4,030	2,076	4,091	-0,028	0,060	5	2,146	4,236	2,224	4,247	0,056	0,199
E02IE	6A	633,7	315,7	612,1	316,5	19.988	2,050	4,115	2,123	4,105	-0,014	0,141	6	2,179	4,294	2,245	4,314	0,065	0,170
E02SD	6A	625,9	318,1	615,9	312,4	20.282	2,106	4,144	2,140	4,220	0,067	0,059	7	2,123	4,195	2,218	4,225	0,050	0,212
E02SE	6A	625,3	318,9	605,5	314,8	21.084	2,192	4,297	2,263	4,353	0,082	0,166	8	2,169	4,234	2,261	4,252	0,104	0,272
E03ID	6A	625,2	312,0	607,9	319,2	20.932	2,164	4,225	2,238	4,262	0,100	0,211	9	2,161	4,264	2,233	4,271	0,056	0,192
E03IE	6A	636,2	319,7	624,2	321,8	20.809	2,126	4,231	2,167	4,203	0,020	0,128	10	2,150	4,208	2,227	4,229	0,089	0,226

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE POLIA MAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	POLY COLUNA DA ESQUERDA				LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	DELTAY	LN1X	LN2X	LN1Y	LN2Y	DELTA	DELTAY		
		R1X	R2X	R1Y	R2Y														
E03SD	6A	630,1	325,9	616,1	317,1	21,261	2,193	4,240	2,243	4,358	0,143	0,121	11	2,163	4,245	2,235	4,228	0,079	0,244
E03SE	6A	638,9	321,4	615,0	317,2	21,147	2,151	4,277	2,235	4,333	0,025	0,130	12	2,166	4,227	2,245	4,257	0,102	0,234
E04ID	6A	642,8	321,1	624,7	322,4	20,591	2,082	4,168	2,142	4,151	-0,004	0,133	13	2,168	4,247	2,263	4,261	0,090	0,266
E04IE	6A	648,7	324,2	615,4	323,2	21,362	2,140	4,283	2,256	4,296	-0,002	0,212	14	2,177	4,285	2,276	4,293	0,066	0,257
E04SD	6A	626,9	328,9	618,3	321,4	21,052	2,183	4,160	2,213	4,258	0,207	0,165	15	2,232	4,352	2,314	4,358	0,106	0,264
E04SE	6A	645,2	323,0	614,9	319,8	19,317	1,946	3,887	2,042	3,926	0,005	0,167	16	2,162	4,232	2,240	4,262	0,092	0,215
E05ID	6A	654,7	326,6	624,8	323,7	21,910	2,175	4,360	2,279	4,399	-0,009	0,150	17	2,171	4,267	2,230	4,246	0,073	0,214
E05IE	6A	648,6	327,0	627,9	327,7	21,582	2,163	4,290	2,234	4,281	0,034	0,183	18	2,210	4,273	2,295	4,334	0,122	0,252
E05SD	6A	634,1	328,5	623,7	328,5	20,780	2,130	4,112	2,166	4,112	0,130	0,226	19	2,171	4,239	2,246	4,219	0,102	0,277
E05SE	6A	642,6	325,2	614,1	324,3	20,932	2,117	4,184	2,216	4,195	0,049	0,238	20	2,132	4,215	2,241	4,258	0,048	0,222
E06ID	6A	635,7	324,4	619,1	325,4	21,822	2,163	4,372	2,291	4,359	-0,042	0,216							
E06IE	6A	642,4	328,3	636,6	327,3	21,109	2,134	4,179	2,155	4,192	0,090	0,116		2,156	4,236	2,235	4,254	0,074	0,215
E06SE	6A	657,3	328,1	628,8	326,9	21,910	2,167	4,340	2,265	4,356	-0,007	0,166		0,035	0,051	0,039	0,047	0,026	0,046
E07ID	6A	650,6	328,0	623,3	328,0	21,082	2,106	4,178	2,199	4,178	0,033	0,221							
E07IE	6A	648,7	332,1	635,6	329,7	21,446	2,149	4,198	2,193	4,228	0,098	0,156							
E07SD	6A	663,1	331,9	619,1	329,9	21,611	2,118	4,232	2,269	4,258	0,004	0,281							
E07SE	6A	657,1	333,9	629,3	328,8	21,425	2,119	4,171	2,213	4,235	0,066	0,188							
E08ID	6A	664,7	329,8	626,7	332,9	21,616	2,114	4,260	2,242	4,221	-0,030	0,266							
E08IE	6A	663,0	335,7	631,4	335,7	22,045	2,161	4,268	2,269	4,268	0,051	0,271							
E08SD	6A	648,3	335,0	628,8	333,5	22,036	2,209	4,276	2,278	4,295	0,139	0,259							
E08SE	6A	641,7	340,2	622,8	332,6	21,623	2,190	4,131	2,257	4,226	0,257	0,292							
E09ID	6A	659,8	336,0	635,3	334,5	21,330	2,101	4,126	2,182	4,145	0,075	0,224							
E09IE	6A	668,9	337,2	646,0	335,8	22,476	2,184	4,332	2,261	4,351	0,033	0,165							
E09SD	6A	656,4	335,6	637,1	336,9	22,020	2,181	4,265	2,247	4,248	0,092	0,245							
E09SE	6A	666,4	335,0	647,5	334,2	22,320	2,177	4,331	2,241	4,341	0,022	0,133							
E10ID	6A	660,9	336,6	630,5	334,0	22,102	2,174	4,268	2,279	4,301	0,076	0,253							
E10IE	6A	657,2	339,1	642,6	337,6	21,316	2,108	4,086	2,156	4,104	0,132	0,214							
E10SD	6A	658,3	337,4	633,7	336,4	21,861	2,159	4,212	2,242	4,224	0,103	0,263							
E10SE	6A	663,3	335,3	641,4	334,0	22,019	2,158	4,268	2,231	4,285	0,045	0,173							
E11ID	6A	669,0	336,2	634,8	337,8	21,955	2,133	4,245	2,248	4,225	0,020	0,275							
E11IE	6A	664,4	333,9	631,8	339,1	22,315	2,183	4,344	2,296	4,277	0,021	0,317							
E11SD	6A	651,8	339,5	639,7	337,6	21,554	2,149	4,127	2,190	4,150	0,174	0,235							
E11SE	6A	658,0	337,0	651,2	337,4	22,115	2,185	4,266	2,207	4,260	0,100	0,150							
E12ID	6A	659,1	337,2	640,5	335,1	22,096	2,179	4,259	2,242	4,286	0,095	0,194							
E12IE	6A	658,5	336,6	633,8	337,0	22,429	2,214	4,331	2,300	4,326	0,091	0,271							
E12SD	6A	653,0	335,5	630,2	337,1	21,530	2,143	4,171	2,221	4,151	0,113	0,300							
E12SE	6A	661,6	339,6	635,0	330,4	21,670	2,129	4,148	2,218	4,263	0,109	0,169							
E13ID	6A	661,5	330,9	628,2	331,9	22,097	2,171	4,341	2,286	4,327	0,002	0,240							
E13IE	6A	655,3	329,8	628,2	334,4	21,954	2,178	4,327	2,272	4,267	0,026	0,276							
E13SD	6A	649,4	334,8	621,6	328,3	21,776	2,180	4,228	2,277	4,311	0,128	0,239							
E13SE	6A	641,7	336,4	620,6	332,6	21,174	2,145	4,091	2,218	4,138	0,204	0,310							
E14ID	6A	656,2	329,6	625,0	330,9	21,898	2,169	4,318	2,277	4,301	0,018	0,250							
E14IE	6A	649,7	329,3	622,3	331,0	21,860	2,187	4,315	2,283	4,293	0,056	0,273							
E14SD	6A	652,8	331,3	629,7	330,2	21,656	2,156	4,249	2,235	4,263	0,061	0,205							
E14SE	6A	644,3	332,3	612,8	327,9	21,760	2,195	4,256	2,308	4,314	0,130	0,302							
E15ID	6A	651,0	330,0	622,3	334,4	22,184	2,215	4,330	2,317	4,312	0,094	0,323							
E15IE	6A	656,3	334,8	630,7	332,6	22,697	2,248	4,406	2,339	4,436	0,083	0,231							
E15SD	6A	645,4	332,7	628,1	333,1	22,285	2,244	4,354	2,306	4,349	0,128	0,258							
E15SE	6A	649,9	334,3	629,5	332,9	22,203	2,221	4,317	2,293	4,335	0,119	0,245							
E16ID	6A	657,2	339,6	632,1	332,0	20,849	2,062	3,990	2,144	4,082	0,139	0,213							
E16IE	6A	662,3	330,3	637,3	333,6	21,697	2,129	4,270	2,213	4,228	-0,010	0,197							
E16SD	6A	648,0	336,8	637,5	331,0	22,035	2,210	4,253	2,247	4,327	0,165	0,160							
E16SE	6A	652,0	331,9	622,1	332,1	22,537	2,247	4,414	2,355	4,411	0,074	0,290							
E17ID	6A	670,3	334,7	633,8	334,2	21,957	2,129	4,264	2,252	4,270	-0,005	0,231							

MEDIDAS DE RESISTENCIA DA FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

DIE	POS	POLY	COLUNA DA ESQUERDA			RS	LW1X	LN2X	LW1Y	LN2Y	DELTA1	DELTA2	LW1X	LN2X	LW1Y	LN2Y	DELTA1X	DELTA1Y
			R1X	R2X	R1Y													
E171E	6A	655,8	337,8	648,0	340,7	21,129	2,094	4,066	2,119	4,031	0,125	0,217						
E175D	6A	659,6	335,4	649,6	335,9	22,693	2,236	4,398	2,271	4,391	0,069	0,142						
E175E	6A	652,3	334,5	636,9	338,3	22,036	2,226	4,340	2,280	4,292	0,105	0,266						
E181D	6A	654,3	334,2	624,4	334,3	22,448	2,230	4,366	2,337	4,365	0,088	0,305						
E181E	6A	657,1	336,6	641,0	334,8	22,581	2,234	4,360	2,290	4,384	0,100	0,187						
E185D	6A	658,7	342,5	633,0	337,4	22,185	2,189	4,210	2,278	4,274	0,166	0,283						
E185E	6A	661,4	341,2	635,6	335,2	22,240	2,186	4,237	2,274	4,313	0,131	0,232						
E191D	6A	665,6	332,4	628,3	335,8	22,214	2,169	4,341	2,298	4,300	-0,002	0,296						
E191E	6A	638,7	335,4	628,7	333,5	21,669	2,205	4,199	2,240	4,223	0,212	0,259						
E195D	6A	639,8	331,7	633,8	335,6	22,047	2,240	4,320	2,261	4,270	0,153	0,251						
E195E	6A	655,9	331,7	622,1	332,8	20,894	2,071	4,094	2,183	4,081	0,046	0,301						
E201D	6A	679,7	341,8	641,2	338,3	22,146	2,118	4,211	2,245	4,255	0,023	0,234						
E201E	6A	667,6	335,6	635,6	339,2	22,130	2,155	4,286	2,243	4,241	0,022	0,289						
E205D	6A	670,9	340,2	641,5	334,3	22,045	2,136	4,212	2,234	4,286	0,057	0,176						
E205E	6A	665,9	340,1	635,4	332,1	21,719	2,120	4,151	2,222	4,251	0,088	0,190						

APÊNDICE III

**TABELA DAS MEDIDAS DE LARGURA DE LINHA EM
ESTRUTURAS DE METAL**

LWMETA

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

6C DIREITA

	METAL	DIE	POS	RIX	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y
5	D011D	6C	1,940	0,997	1,903	0,980	0,064	2,144	4,173	2,186	4,245	0,115	0,124	1	2,137	4,151	2,162	4,158	0,122	0,166
3	D011E	6C	1,949	0,999	1,948	1,010	0,063	2,101	4,099	2,102	4,054	0,103	0,154	2	2,045	4,075	2,100	4,122	0,056	0,078
7	D015B	6C	1,908	0,984	1,865	0,967	0,063	2,129	4,129	2,178	4,201	0,130	0,154	3	2,062	4,065	2,098	4,125	0,060	0,071
1	D01SE	6C	1,899	0,982	1,893	0,999	0,064	2,174	4,203	2,180	4,132	0,142	0,235	4	2,054	4,064	2,076	4,109	0,043	0,083
13	D021D	6C	2,010	1,005	1,934	0,981	0,064	2,053	4,107	2,134	4,207	0,000	0,059	5	2,046	4,065	2,080	4,103	0,028	0,058
11	D021E	6C	1,992	1,011	1,956	1,007	0,063	2,056	4,050	2,094	4,067	0,061	0,122	6	2,018	4,006	2,066	4,045	0,029	0,089
15	D02SD	6C	1,962	0,999	1,926	0,974	0,063	2,087	4,079	2,126	4,204	0,075	0,046	7	2,016	4,024	2,078	4,065	0,007	0,092
9	D02SE	6C	1,967	1,005	1,985	1,013	0,063	2,065	4,042	2,047	4,010	0,089	0,084	8	1,996	3,998	2,063	4,036	-0,006	0,091
21	D031D	6C	1,979	1,001	1,910	0,970	0,063	2,089	4,091	2,144	4,222	0,047	0,064	9	1,988	4,018	2,068	4,043	-0,041	0,096
19	D031E	6C	1,991	1,009	1,984	1,012	0,063	2,057	4,058	2,064	4,046	0,055	0,082	10	1,999	4,019	2,093	4,064	-0,020	0,125
23	D03SD	6C	1,963	1,004	1,911	0,972	0,063	2,086	4,079	2,143	4,213	0,094	0,070	11	2,031	4,083	2,123	4,132	0,020	0,115
17	D03SE	6C	1,994	1,008	1,989	1,011	0,063	2,037	4,030	2,042	4,018	0,045	0,067	12	2,048	4,084	2,121	4,154	0,009	0,089
29	D041D	6C	1,973	1,005	1,924	0,978	0,064	2,092	4,107	2,145	4,220	0,076	0,068	13	2,048	4,065	2,117	4,139	0,031	0,095
27	D041E	6C	1,996	1,004	1,969	1,014	0,063	2,035	4,038	2,063	4,006	0,032	0,124	14	2,048	4,089	2,129	4,154	0,007	0,104
31	D045D	6C	1,988	1,004	1,918	0,974	0,063	2,046	4,046	2,148	4,171	0,045	0,064	15	2,059	4,104	2,136	4,120	0,012	0,154
25	D04SE	6C	2,006	1,008	1,991	1,014	0,063	2,041	4,063	2,057	4,038	0,020	0,076	16	2,058	4,048	2,121	4,104	0,070	0,140
37	D051D	6C	1,984	1,005	1,944	0,983	0,063	2,064	4,075	2,106	4,166	0,053	0,046	17	2,068	4,085	2,127	4,109	0,049	0,146
35	D051E	6C	1,995	1,008	1,952	1,008	0,063	2,053	4,071	2,078	4,063	0,034	0,136	18	2,077	4,118	2,136	4,128	0,036	0,146
39	D059D	6C	2,002	1,008	1,970	0,978	0,063	2,045	4,063	2,079	4,187	0,028	-0,028	19	2,065	4,067	2,125	4,064	0,063	0,193
33	D05SE	6C	2,024	1,011	2,012	1,025	0,063	2,023	4,050	2,035	3,995	-0,004	0,077	20	2,055	4,057	2,115	4,061	0,053	0,174
45	D061D	6C	1,991	1,004	1,922	0,977	0,062	2,008	3,982	2,080	4,092	0,034	0,068							
43	D061E	6C	2,006	1,009	1,969	1,014	0,062	1,993	3,962	2,030	3,942	0,024	0,124	MED2	0,048	4,064	2,108	4,102	0,032	0,115
47	D065D	6C	1,986	1,004	1,917	0,978	0,063	2,046	4,046	2,119	4,154	0,045	0,063	S160	0,032	0,037	0,026	0,039	0,035	0,037
41	D065E	6C	2,007	1,007	1,997	1,018	0,063	2,024	4,034	2,034	3,991	0,014	0,080							
53	D071D	6C	2,021	1,007	1,935	0,986	0,063	2,010	4,034	2,099	4,120	-0,014	0,078							
51	D071E	6C	2,031	1,014	1,985	1,018	0,062	1,984	3,974	2,030	3,959	-0,006	0,105							
55	D075D	6C	1,999	1,007	1,924	0,975	0,063	2,049	4,067	2,128	4,200	0,030	0,055							
49	D075E	6C	2,011	1,010	1,978	1,020	0,063	2,020	4,022	2,054	3,983	0,018	0,129							
61	D081D	6C	2,049	1,012	1,936	0,986	0,063	1,983	4,014	2,098	4,120	-0,048	0,076							
59	D081E	6C	2,039	1,019	1,996	1,023	0,063	1,992	3,987	2,035	3,971	-0,002	0,103							
63	D085D	6C	2,013	1,011	1,936	0,987	0,063	2,018	4,018	2,098	4,116	0,018	0,080							
57	D085E	6C	2,023	1,014	1,997	1,024	0,062	1,992	3,974	2,018	3,936	0,010	0,105							
69	D091D	6C	2,046	1,015	1,954	0,992	0,063	2,001	4,034	2,096	4,128	-0,031	0,062							
67	D091E	6C	2,062	1,020	1,985	1,028	0,063	1,970	3,983	2,047	3,952	-0,042	0,148							
71	D095D	6C	2,050	1,013	1,961	0,985	0,063	1,982	4,010	2,072	4,124	-0,046	0,018							
65	D095E	6C	2,050	1,013	1,990	1,032	0,063	1,998	4,042	2,058	3,968	-0,046	0,154							
77	D101D	6C	2,039	1,017	1,945	0,991	0,063	2,008	4,027	2,105	4,132	-0,010	0,078							
75	D101E	6C	2,053	1,023	1,985	1,030	0,063	1,979	3,971	2,047	3,944	-0,014	0,157							
79	D105D	6C	2,054	1,018	1,934	0,986	0,063	1,994	4,023	2,117	4,153	-0,035	0,080							
73	D105E	6C	2,047	1,018	1,963	1,025	0,064	2,016	4,055	2,103	4,027	-0,021	0,186							
85	D111D	6C	2,034	1,021	1,947	0,993	0,064	2,045	4,074	2,137	4,189	0,016	0,082							
83	D111E	6C	2,044	1,021	1,986	1,030	0,064	2,035	4,074	2,095	4,039	-0,004	0,155							
87	D115D	6C	2,004	1,012	1,919	0,980	0,064	2,076	4,111	2,168	4,245	0,040	0,087							
81	D115E	6C	2,015	1,014	1,972	1,018	0,064	2,048	4,071	2,093	4,055	0,026	0,134							
93	D121D	6C	2,046	1,020	1,960	0,985	0,064	2,033	4,078	2,122	4,223	-0,012	0,021							
91	D121E	6C	2,062	1,024	1,979	1,027	0,064	2,017	4,063	2,102	4,051	-0,027	0,158							
95	D125D	6C	2,002	1,013	1,930	0,982	0,063	2,045	4,042	2,122	4,170	0,049	0,072							
89	D125E	6C	2,017	1,015	1,975	1,013	0,065	2,095	4,163	2,139	4,171	0,026	0,106							
101	D131D	6C	2,045	1,024	1,969	0,990	0,065	2,050	4,094	2,129	4,235	0,006	0,022							
99	D131E	6C	2,044	1,030	1,965	1,029	0,064	2,019	4,007	2,101	4,011	0,032	0,199							
103	D135D	6C	2,004	1,014	1,935	0,979	0,064	2,076	4,103	2,150	4,249	0,048	0,048							
97	D135E	6C	2,016	1,018	1,978	1,016	0,064	2,047	4,055	2,087	4,063	0,040	0,112							
109	D141D	6C	2,003	1,004	1,907	0,973	0,063	2,045	4,079	2,148	4,209	0,010	0,084							
107	D141E	6C	2,019	1,009	1,948	1,007	0,064	2,044	4,089	2,119	4,098	-0,001	0,142							

LWNETA

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

6C DIREITA

METAL

DIE	POS	RIX	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y	
111	D14SD	6C	2,008	0,999	1,906	0,964	0,063	2,023	4,065	2,132	4,214	-0,018	0,047						
105	D14SE	6C	1,984	1,001	1,948	1,008	0,064	2,081	4,123	2,119	4,096	0,038	0,143						
117	D15ID	6C	1,989	1,004	1,906	0,984	0,063	2,059	4,077	2,149	4,160	0,041	0,137						
115	D15IE	6C	2,029	1,010	1,960	1,027	0,063	2,018	4,055	2,089	3,986	-0,019	0,202						
119	D15SD	6C	2,002	1,001	1,914	0,980	0,064	2,061	4,122	2,157	4,213	0,000	0,097						
113	D15SE	6C	1,999	1,006	1,952	1,018	0,065	2,078	4,168	2,148	4,120	0,026	0,178						
125	D16ID	6C	2,025	1,021	1,969	1,003	0,064	2,038	4,044	2,097	4,115	0,033	0,077						
123	D16IE	6C	2,047	1,027	1,991	1,035	0,064	2,033	4,051	2,089	4,019	0,014	0,166						
127	D16SD	6C	1,992	1,045	1,904	0,986	0,065	2,105	4,012	2,199	4,232	0,208	0,143						
121	D16SE	6C	2,023	1,018	1,982	1,032	0,064	2,056	4,087	2,099	4,031	0,026	0,172						
133	D17ID	6C	2,035	1,020	1,952	0,999	0,064	2,044	4,077	2,132	4,166	0,011	0,096						
131	D17IE	6C	2,025	1,026	1,975	1,043	0,063	2,022	3,992	2,074	3,928	0,032	0,237						
135	D17SD	6C	1,989	1,013	1,923	0,986	0,065	2,108	4,139	2,180	4,252	0,075	0,105						
129	D17SE	6C	2,015	1,022	1,991	1,033	0,065	2,097	4,134	2,122	4,088	0,058	0,158						
141	D18ID	6C	2,030	1,026	1,969	1,005	0,066	2,114	4,181	2,179	4,248	0,045	0,086						
139	D18IE	6C	2,029	1,011	1,986	1,038	0,064	2,050	4,115	2,095	4,009	-0,015	0,189						
143	D18SD	6C	1,996	1,019	1,928	0,995	0,065	2,100	4,114	2,175	4,212	0,086	0,136						
137	D18SE	6C	2,033	1,024	1,986	1,034	0,064	2,046	4,062	2,095	4,022	0,030	0,173						
149	D19ID	6C	2,030	1,030	1,942	1,020	0,064	2,033	4,009	2,128	4,047	0,058	0,212						
147	D19IE	6C	2,043	1,032	1,994	1,051	0,065	2,068	4,095	2,119	4,019	0,040	0,231						
151	D19SD	6C	1,999	1,020	1,929	0,999	0,064	2,081	4,079	2,157	4,166	0,082	0,148						
145	D19SE	6C	2,018	1,026	1,997	1,042	0,065	2,077	4,085	2,099	4,024	0,069	0,181						
157	D20ID	6C	2,034	1,031	1,960	1,016	0,065	2,061	4,068	2,139	4,127	0,054	0,153						
155	D20IE	6C	2,059	1,039	2,003	1,057	0,065	2,036	4,036	2,073	3,967	0,036	0,232						
159	D20SD	6C	2,013	1,025	1,937	1,004	0,064	2,067	4,059	2,148	4,142	0,075	0,154	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTAX	DELTAY
153	D20SE	6C	2,039	1,031	2,017	1,046	0,065	2,036	4,065	2,079	4,007	0,046	0,156						
165	E01ID	6C	1,932	0,979	1,908	0,973	0,063	2,081	4,067	2,129	4,175	0,097	0,061	1,2,065	4,038	2,086	4,087	0,094	0,085
163	E01IE	6C	1,972	1,006	1,989	1,010	0,063	2,060	4,038	2,042	4,022	0,063	0,063	2,2,023	3,986	2,058	4,039	0,063	0,080
167	E01SD	6C	1,979	1,000	1,920	0,972	0,062	2,020	3,998	2,082	4,113	0,043	0,051	3,2,030	3,998	2,053	4,051	0,062	0,056
161	E01SE	6C	1,935	1,003	1,944	1,006	0,063	2,059	4,050	2,090	4,038	0,152	0,145	4,2,015	4,000	2,067	4,058	0,031	0,075
173	E02ID	6C	2,042	1,010	1,956	0,987	0,062	1,974	3,990	2,060	4,083	-0,043	0,037	5,2,006	3,965	2,040	4,035	0,050	0,045
171	E02IE	6C	1,957	1,013	1,971	1,013	0,062	2,059	3,978	2,045	3,978	0,146	0,115	6,1,999	3,974	2,042	4,034	0,024	0,050
175	E02SD	6C	2,012	1,004	1,936	0,978	0,062	2,003	4,014	2,082	4,121	-0,008	0,042	7,2,008	3,989	2,056	4,046	0,028	0,068
169	E02SE	6C	1,945	1,009	1,953	1,006	0,062	2,055	3,962	2,047	3,974	0,156	0,125	8,2,002	4,009	2,069	4,071	-0,005	0,068
181	E03ID	6C	2,012	1,013	1,955	0,982	0,062	2,003	3,978	2,061	4,104	0,028	0,018	9,2,005	4,034	2,108	4,091	-0,023	0,126
179	E03IE	6C	1,970	1,011	2,006	1,014	0,063	2,079	4,050	2,041	4,038	0,108	0,044	10,2,037	4,086	2,128	4,156	-0,012	0,100
183	E03SD	6C	2,010	1,009	1,957	0,981	0,062	2,005	3,994	2,059	4,108	0,016	0,010	11,2,020	4,055	2,120	4,139	-0,015	0,101
177	E03SE	6C	1,983	1,015	1,947	1,019	0,062	2,032	3,970	2,049	3,955	0,097	0,150	12,2,027	4,021	2,097	4,118	0,035	0,076
189	E04ID	6C	2,023	1,002	1,904	0,975	0,062	1,992	4,022	2,117	4,133	-0,037	0,099	13,2,029	4,047	2,108	4,148	0,012	0,068
187	E04IE	6C	1,967	1,002	1,960	1,001	0,062	2,032	3,990	2,040	3,994	0,077	0,088	14,2,013	4,033	2,107	4,123	-0,009	0,092
191	E04SD	6C	1,997	0,998	1,914	0,967	0,061	1,985	3,973	2,072	4,100	-0,002	0,042	15,2,030	4,023	2,096	4,078	0,039	0,116
185	E04SE	6C	1,967	1,004	1,977	1,006	0,062	2,049	4,014	2,038	4,006	0,085	0,072	16,2,042	4,078	2,126	4,112	0,007	0,143
197	E05ID	6C	2,004	1,007	1,922	0,975	0,062	1,993	3,970	2,080	4,100	0,016	0,059	17,2,048	4,072	2,133	4,113	0,025	0,155
195	E05IE	6C	1,955	1,004	1,973	0,997	0,062	2,045	3,982	2,026	4,010	0,111	0,043	18,2,020	4,012	2,112	4,058	0,029	0,171
199	E05SD	6C	2,025	1,003	1,933	0,972	0,062	1,974	3,986	2,048	4,113	-0,037	0,023	19,2,020	3,973	2,100	4,006	0,070	0,203
193	E05SE	6C	1,969	1,011	1,996	1,012	0,061	2,014	3,922	1,986	3,918	0,111	0,057	20,2,017	3,974	2,098	4,010	0,061	0,198
205	E06ID	6C	2,040	1,014	1,955	0,983	0,062	1,960	3,942	2,045	4,067	-0,023	0,023						
203	E06IE	6C	1,984	1,010	1,976	1,009	0,062	2,031	3,990	2,039	3,994	0,074	0,087	MED2,023	4,018	2,090	4,079	0,028	0,104
207	E06SD	6C	2,030	1,008	1,941	0,982	0,062	1,985	3,998	2,076	4,104	-0,027	0,048	S160,016	0,036	0,029	0,044	0,031	0,046
201	E06SE	6C	1,997	1,016	2,006	1,015	0,062	2,018	3,947	2,007	3,970	0,071	0,044						
213	E07ID	6C	2,023	1,014	1,941	0,983	0,063	2,024	4,038	2,110	4,166	0,010	0,052						
211	E07IE	6C	2,002	1,016	1,977	1,010	0,062	2,013	3,967	2,038	3,990	0,061	0,089						
215	E07SD	6C	2,022	1,012	1,951	0,986	0,062	1,993	3,982	2,068	4,087	0,004	0,044						
209	E07SE	6C	2,012	1,015	2,004	1,023	0,062	2,003	3,970	2,011	3,939	0,036	0,086						

LUMETA

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE TOLNA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

6C DIREITA

METAL

DIE POS R1X R2X R1Y R2Y RS LM1X LM2X LM1Y LM2Y DEL_X DEL_Y LM1X LM2X LM1Y LM2Y DEL_X DEL_Y

221	E081D	6C	2,056	1,016	1,950	0,984	0,064	2,023	4,094	2,133	4,228	-0,046	0,037
219	E081E	6C	2,016	1,015	1,966	1,018	0,062	1,999	3,970	2,050	3,759	0,028	0,148
223	E08SD	6C	2,056	1,013	1,953	0,982	0,062	1,960	3,978	2,063	4,104	-0,058	0,023
217	E08SE	6C	2,007	1,017	2,003	1,017	0,063	2,024	3,995	2,028	3,995	0,055	0,063
239	E091D	6C	2,045	1,017	1,931	0,990	0,063	1,983	4,027	2,121	4,136	-0,059	0,104
227	E091E	6C	2,029	1,017	1,956	1,021	0,063	2,018	4,027	2,094	4,011	0,010	0,184
231	E09SD	6C	2,084	1,016	1,930	0,984	0,064	1,981	4,063	2,139	4,195	-0,097	0,080
225	E09SE	6C	2,010	1,019	1,971	1,018	0,063	2,037	4,019	2,078	4,023	0,057	0,136
237	E101D	6C	2,065	1,007	1,933	0,979	0,063	1,983	4,047	2,118	4,183	-0,096	0,032
235	E101E	6C	2,022	1,011	1,948	1,006	0,064	2,041	4,083	2,119	4,103	0,000	0,136
239	E105D	6C	2,005	1,005	1,930	0,973	0,064	2,059	4,107	2,139	4,242	0,010	0,033
233	E10SE	6C	2,000	1,010	1,934	1,008	0,064	2,064	4,087	2,134	4,095	0,040	0,177
245	E111D	6C	2,064	1,014	1,915	0,978	0,064	2,016	4,103	2,172	4,254	-0,089	0,088
243	E111E	6C	2,027	1,019	1,964	1,011	0,063	2,004	3,987	2,068	4,018	0,022	0,122
247	E115D	6C	2,014	1,008	1,926	0,977	0,064	2,049	4,075	2,143	4,225	0,004	0,059
241	E115E	6C	2,038	1,015	1,953	1,009	0,063	2,009	4,034	2,097	4,658	-0,016	0,138
253	E121D	6C	2,064	1,025	1,941	0,989	0,064	2,000	4,027	2,126	4,173	-0,027	0,078
251	E121E	6C	2,024	1,026	1,997	1,020	0,063	2,023	3,991	2,051	4,015	0,056	0,088
255	E12SD	6C	2,022	1,016	1,925	0,972	0,063	2,025	4,031	2,127	4,213	0,020	0,040
249	E12SE	6C	2,002	1,023	1,981	1,014	0,064	2,062	4,035	2,084	4,071	0,090	0,097
261	E131D	6C	2,094	1,025	1,958	0,985	0,064	1,987	4,059	2,125	4,223	-0,082	0,025
259	E131E	6C	2,039	1,028	1,989	1,019	0,064	2,024	4,015	2,075	4,051	0,034	0,101
263	E13SD	6C	2,009	1,013	1,943	0,973	0,064	2,055	4,075	2,124	4,242	0,034	0,066
257	E13SE	6C	2,013	1,022	1,959	1,013	0,064	2,050	4,039	2,107	4,075	0,063	0,142
269	E141D	6C	2,088	1,025	1,948	0,992	0,063	1,961	3,995	2,102	4,128	-0,071	0,075
267	E141E	6C	2,052	1,026	1,987	1,019	0,064	2,027	4,055	2,094	4,082	0,000	0,165
271	E145D	6C	2,057	1,019	1,958	0,974	0,063	1,975	3,987	2,075	4,171	-0,037	-0,020
265	E145E	6C	2,009	1,022	1,944	1,020	0,065	2,087	4,102	2,157	4,110	0,071	0,208
277	E151D	6C	2,068	1,027	1,970	1,000	0,064	1,976	4,019	2,095	4,128	-0,027	0,062
275	E151E	6C	2,015	1,030	1,981	1,033	0,064	2,048	4,007	2,077	3,996	0,091	0,166
279	E155D	6C	2,017	1,017	1,930	0,986	0,063	2,030	4,027	2,122	4,153	0,034	0,089
273	E155E	6C	2,016	1,022	1,976	1,023	0,064	2,047	4,039	2,089	4,035	0,056	0,147
285	E161D	6C	2,068	1,024	1,954	0,997	0,064	1,998	4,031	2,112	4,140	-0,038	0,084
283	E161E	6C	2,038	1,028	1,965	1,034	0,064	2,073	4,118	2,150	4,084	0,028	0,221
287	E165D	6C	2,018	1,011	1,930	0,984	0,065	2,078	4,147	2,172	4,252	0,008	0,089
281	E165E	6C	2,024	1,020	1,977	1,032	0,063	2,023	4,015	2,069	3,968	0,032	0,180
293	E171D	6C	2,069	1,031	1,946	1,008	0,067	2,069	4,193	2,221	4,288	-0,051	0,149
291	E171E	6C	2,032	1,032	1,978	1,040	0,064	2,047	4,031	2,103	4,000	0,064	0,217
295	E17SD	6C	2,032	1,022	1,934	0,995	0,064	2,047	4,070	2,149	4,181	0,024	0,115
289	E17SE	6C	2,031	1,033	2,005	1,036	0,064	2,028	3,996	2,059	3,984	0,062	0,138
301	E181D	6C	2,061	1,034	1,952	1,008	0,064	1,999	4,023	2,131	4,127	-0,025	0,134
299	E181E	6C	2,041	1,038	1,989	1,043	0,064	2,038	4,008	2,092	3,988	0,070	0,205
303	E18SD	6C	2,041	1,025	1,920	0,995	0,064	2,038	4,059	2,167	4,181	0,018	0,151
297	E18SE	6C	2,042	1,034	1,989	1,040	0,063	2,005	3,980	2,059	3,938	0,052	0,192
309	E191D	6C	2,074	1,044	1,962	1,019	0,064	1,990	3,954	2,104	4,051	0,027	0,161
307	E191E	6C	2,043	1,048	2,004	1,055	0,064	2,036	3,989	2,076	3,943	0,107	0,223
311	E195D	6C	2,046	1,035	1,918	1,006	0,064	2,017	3,988	2,152	4,103	0,047	0,204
305	E195E	6C	2,025	1,037	1,997	1,051	0,064	2,038	3,980	2,067	3,927	0,099	0,222
317	E201D	6C	2,102	1,045	1,969	1,025	0,064	1,979	3,981	2,113	4,059	-0,023	0,172
315	E201E	6C	2,054	1,050	1,994	1,060	0,064	2,009	3,931	2,070	3,894	0,092	0,270
319	E205D	6C	2,049	1,036	1,961	1,003	0,064	2,014	3,984	2,105	4,115	0,045	0,094
313	E205E	6C	2,016	1,040	1,975	1,047	0,064	2,063	4,000	2,106	3,973	0,131	0,256
6	D011D	7C	1,942	0,984	1,924	0,988	0,064	2,075	4,087	2,095	4,079	0,063	0,111
4	D011E	7C	1,952	0,993	1,996	1,038	0,063	2,081	4,091	2,035	3,914	0,071	0,167

7C DIREITA

LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DELTA_X	DELTA_Y
1 2,041	4,050	2,075	4,010	0,033	0,147
2 2,035	4,034	2,063	4,003	0,036	0,129

LWNETA

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

6C DIREITA

METAL

	BIE	POS	RIX	R2X	R1Y	R2Y	RS	LWIX	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y	LNX	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y	
8	D01SD	TC	1.974	1.000	1.917	0.992	0.062	2.042	4.030	2.102	4.063	0.053	0.145	3	2.033	4.041	2.075	4.011	0.025	0.144
2	D01SE	TC	2.065	1.018	1.963	1.020	0.063	1.967	3.991	2.070	3.983	-0.055	0.163	4	2.045	4.077	2.085	4.045	0.014	0.129
14	D02ID	TC	1.961	0.996	1.955	0.995	0.063	2.072	4.079	2.078	4.083	0.064	0.073	5	2.019	4.056	2.077	4.027	-0.017	0.131
12	D02IE	TC	1.985	0.999	2.002	1.041	0.062	2.014	4.002	1.997	3.840	0.026	0.166	6	1.979	3.979	2.050	3.942	-0.021	0.167
16	D02SD	TC	1.978	1.000	1.945	0.991	0.063	2.054	4.063	2.089	4.099	0.045	0.078	7	1.958	3.962	2.043	3.921	-0.047	0.177
10	D02SE	TC	2.046	1.025	1.959	1.026	0.063	2.001	3.995	2.090	3.991	0.008	0.199	8	1.961	3.988	2.050	3.947	-0.065	0.164
22	D03ID	TC	1.945	0.992	1.918	0.994	0.062	2.072	4.063	2.101	4.054	0.082	0.152	9	1.969	4.023	2.077	3.987	-0.082	0.176
20	D03IE	TC	1.988	0.998	1.996	1.005	0.063	2.044	4.071	2.035	3.925	0.016	0.134	10	1.959	3.976	2.086	3.964	-0.075	0.223
24	D03SD	TC	1.975	1.002	1.933	0.991	0.063	2.057	4.034	2.102	4.099	0.060	0.104	11	2.007	4.039	2.094	3.997	-0.023	0.202
18	D03SE	TC	2.090	1.030	1.987	1.033	0.063	1.959	3.976	2.061	3.964	-0.057	0.166	12	2.003	4.021	2.077	3.985	-0.015	0.179
30	D04ID	TC	1.934	0.991	1.919	0.991	0.063	2.101	4.099	2.117	4.099	0.102	0.136	13	2.024	4.068	2.114	4.037	-0.018	0.200
28	D04IE	TC	1.958	0.998	2.005	1.035	0.063	2.091	4.103	2.042	3.957	0.079	0.134	14	2.013	4.090	2.130	4.051	-0.062	0.219
32	D04SD	TC	1.998	0.998	1.943	0.996	0.063	2.050	4.103	2.108	4.111	-0.004	0.103	15	2.032	4.078	2.106	4.022	-0.011	0.201
26	D04SE	TC	2.128	1.031	1.970	1.029	0.064	1.940	4.003	2.074	4.011	-0.120	0.142	16	2.025	4.049	2.106	3.984	0.001	0.248
38	D05ID	TC	1.980	0.998	1.937	0.997	0.063	2.052	4.071	2.097	4.075	0.033	0.121	17	2.027	4.045	2.117	3.983	0.009	0.271
36	D05IE	TC	1.997	1.005	2.009	1.041	0.063	2.051	4.075	2.038	3.934	0.026	0.151	18	2.024	4.030	2.102	3.978	0.018	0.244
40	D05SD	TC	2.016	1.006	1.955	0.999	0.063	2.015	4.038	2.078	4.067	-0.008	0.090	19	2.033	4.073	2.123	4.023	-0.006	0.235
34	D05SE	TC	2.124	1.030	1.986	1.032	0.064	1.959	4.039	2.095	4.031	-0.117	0.164	20	2.029	4.037	2.108	3.966	0.021	0.272
46	D06ID	TC	1.985	0.991	1.910	0.997	0.061	2.018	4.001	2.078	3.977	0.035	0.184							
44	D06IE	TC	1.995	1.002	1.985	1.039	0.062	2.004	3.990	2.014	3.847	0.018	0.197							
48	D06SD	TC	2.019	1.001	1.947	0.997	0.062	1.996	4.026	2.070	4.042	-0.033	0.099	MED2	0.011	4.037	2.088	3.994	-0.014	0.193
42	D06SE	TC	2.123	1.033	1.977	1.033	0.062	1.898	3.901	2.038	3.901	-0.105	0.189	S160	0.029	0.034	0.025	0.034	0.035	0.045
54	D07ID	TC	1.999	0.996	1.939	0.999	0.062	2.016	4.046	2.078	4.034	-0.014	0.128							
32	D07IE	TC	2.012	1.003	1.970	1.045	0.062	1.987	3.986	2.009	3.925	-0.012	0.212							
56	D07SD	TC	2.034	1.010	1.940	1.000	0.062	1.965	3.958	2.061	3.998	-0.027	0.128							
50	D07SE	TC	2.147	1.036	1.976	1.045	0.062	1.862	3.859	2.023	3.825	-0.135	0.245							
62	D08ID	TC	2.015	1.003	1.962	1.007	0.063	2.032	4.083	2.087	4.067	-0.018	0.189							
60	D08IE	TC	2.044	1.010	2.003	1.058	0.063	2.003	4.054	2.044	3.871	-0.046	0.239							
64	D08SD	TC	2.052	1.011	1.961	1.004	0.062	1.964	3.988	2.055	4.014	-0.058	0.098							
58	D08SE	TC	2.169	1.046	1.985	1.042	0.062	1.843	3.822	2.014	3.836	-0.137	0.210							
70	D09ID	TC	2.022	1.005	1.958	1.013	0.063	2.023	4.075	2.091	4.042	-0.024	0.144							
68	D09IE	TC	2.030	1.007	1.997	1.055	0.063	2.017	4.067	2.051	3.882	-0.031	0.240							
72	D09SD	TC	2.087	1.024	1.977	1.010	0.063	1.947	3.967	2.055	4.022	-0.073	0.089							
66	D09SE	TC	2.222	1.052	1.987	1.048	0.065	1.887	3.985	2.110	4.000	-0.202	0.232							
78	D10ID	TC	2.000	1.006	1.945	1.014	0.063	2.031	4.038	2.089	4.006	0.024	0.178							
76	D10IE	TC	2.029	1.010	1.963	1.049	0.063	2.002	4.022	2.070	3.873	-0.018	0.295							
80	D10SD	TC	2.082	1.018	1.952	1.008	0.063	1.951	3.991	2.081	4.030	-0.086	0.136							
74	D10SE	TC	2.231	1.050	1.962	1.046	0.064	1.850	3.931	2.104	3.946	-0.222	0.284							
86	D11ID	TC	2.005	1.004	1.944	1.006	0.063	2.042	4.071	2.106	4.063	0.014	0.154							
84	D11IE	TC	1.993	1.006	1.972	1.040	0.063	2.055	4.071	2.077	3.938	0.039	0.232							
88	D11SD	TC	2.034	1.012	1.950	1.008	0.063	1.997	4.014	2.083	4.030	-0.020	0.140							
82	D11SE	TC	2.150	1.040	1.972	1.051	0.064	1.935	4.000	2.110	3.958	-0.126	0.282							
94	D12ID	TC	2.004	1.007	1.960	1.012	0.063	2.027	4.026	2.073	4.014	0.028	0.135							
92	D12IE	TC	2.012	1.015	2.000	1.056	0.064	2.051	4.067	2.064	3.909	0.036	0.237							
96	D12SD	TC	2.034	1.013	1.962	1.007	0.064	2.029	4.075	2.104	4.099	-0.016	0.109							
90	D12SE	TC	2.151	1.046	1.981	1.045	0.063	1.904	3.915	2.067	3.919	-0.107	0.233							
102	D13ID	TC	2.005	1.010	1.952	1.013	0.064	2.075	4.119	2.131	4.107	0.030	0.158							
100	D13IE	TC	2.022	1.014	1.988	1.050	0.064	2.057	4.103	2.093	3.962	0.012	0.239							
104	D13SD	TC	2.021	1.013	1.934	1.007	0.064	2.058	4.107	2.151	4.131	0.010	0.173							
98	D13SE	TC	2.164	1.047	1.982	1.045	0.064	1.907	3.942	2.082	3.950	-0.125	0.231							
110	D14ID	TC	1.994	0.999	1.913	0.998	0.064	2.070	4.169	2.158	4.145	-0.028	0.172							
108	D14IE	TC	2.001	0.992	1.969	1.035	0.063	2.046	4.127	2.080	3.957	-0.033	0.217							
112	D14SD	TC	2.008	0.999	1.890	0.995	0.063	2.023	4.066	2.149	4.084	-0.020	0.221							
106	D14SE	TC	2.159	1.032	1.934	1.027	0.064	1.912	3.998	2.134	4.019	-0.167	0.264							

LWMETA

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

AC DIREITA

	METAL	DIE	POS	R1X	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	BEL,X	BEL,Y	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	BEL,X	BEL,Y
118	D151D	TC	1,985	0,993	1,947	1,004	0,063	2,063	4,124	2,103	4,079	0,001	0,128							
116	D151E	TC	1,983	1,002	1,954	1,047	0,064	2,097	4,152	2,129	3,974	0,042	0,306							
120	D15SD	TC	1,983	1,007	1,948	1,004	0,063	2,048	4,033	2,085	4,047	0,064	0,126							
114	D15SE	TC	2,148	1,031	1,958	1,035	0,064	1,922	4,001	2,108	3,987	-0,152	0,244							
126	D161D	TC	1,997	1,007	1,935	1,014	0,064	2,068	4,077	2,133	4,070	0,036	0,203							
124	D161E	TC	2,002	1,011	1,980	1,054	0,064	2,078	4,116	2,101	3,946	0,041	0,277							
128	D16SD	TC	2,010	1,008	1,940	1,017	0,064	2,054	4,096	2,128	4,059	0,011	0,204							
122	D16SE	TC	2,135	1,045	1,963	1,052	0,063	1,903	3,887	2,069	3,863	-0,063	0,308							
134	D171D	TC	1,988	1,009	1,946	1,015	0,063	2,059	4,057	2,104	4,034	0,061	0,181							
132	D171E	TC	2,009	1,015	1,975	1,057	0,064	2,070	4,099	2,106	3,937	0,041	0,301							
136	D17SD	TC	2,032	1,015	1,914	1,016	0,063	2,016	4,033	2,139	4,029	-0,001	0,265							
130	D17SE	TC	2,120	1,043	1,963	1,058	0,064	1,963	3,990	2,119	3,933	-0,063	0,335							
142	D181D	TC	2,006	1,015	1,944	1,025	0,064	2,058	4,065	2,101	4,027	0,051	0,183							
140	D181E	TC	2,008	1,020	1,982	1,060	0,064	2,072	4,080	2,099	3,923	0,063	0,301							
144	D18SD	TC	2,029	1,022	1,959	1,019	0,064	2,034	4,037	2,104	4,049	0,032	0,169							
138	D18SE	TC	2,153	1,056	1,979	1,063	0,064	1,932	3,939	2,102	3,913	-0,074	0,322							
150	D191D	TC	2,022	1,018	1,949	1,027	0,065	2,090	4,151	2,168	4,115	0,028	0,227							
148	D191E	TC	2,010	1,019	2,014	1,067	0,065	2,102	4,148	2,098	3,960	0,055	0,254							
152	D19SD	TC	2,051	1,025	1,958	1,024	0,064	2,029	4,039	2,125	4,064	-0,002	0,191							
146	D19SE	TC	2,191	1,066	1,996	1,060	0,065	1,913	3,933	2,101	3,954	-0,105	0,268							
158	D201D	TC	2,010	1,041	1,959	1,060	0,065	2,084	4,029	2,140	3,954	0,147	0,359							
156	D201E	TC	2,025	1,022	2,008	1,070	0,065	2,086	4,132	2,104	3,949	0,039	0,280							
160	D205D	TC	2,029	1,027	1,963	1,022	0,064	2,051	4,051	2,119	4,070	0,051	0,173							
154	D205E	TC	2,199	1,056	2,010	1,070	0,064	1,892	3,938	2,070	3,889	-0,150	0,275							
166	E011D	TC	1,995	0,995	1,947	0,994	0,061	1,987	3,985	2,034	3,981	-0,010	0,095	1	1,985	3,949	2,016	3,928	0,024	0,111
164	E011E	TC	1,912	0,998	1,963	1,031	0,061	2,074	3,973	2,020	3,846	0,184	0,212	2	1,984	3,966	2,023	3,955	0,004	0,095
168	E01SD	TC	2,033	1,008	1,958	0,994	0,061	1,950	3,934	2,025	3,989	-0,033	0,062	3	1,997	3,976	2,041	3,960	0,019	0,128
162	E01SE	TC	2,071	1,024	2,016	1,028	0,062	1,930	3,904	1,983	3,896	-0,044	0,073	4	1,997	3,991	2,046	3,969	0,003	0,134
174	E021D	TC	2,019	0,997	1,952	0,998	0,062	1,980	4,010	2,048	4,066	-0,049	0,092	5	1,985	3,963	2,028	3,942	-0,034	0,103
172	E021E	TC	1,963	1,004	2,016	1,028	0,061	2,020	3,949	1,967	3,857	0,094	0,081	6	1,963	3,927	2,005	3,892	-0,000	0,126
176	E02SD	TC	2,047	1,006	1,951	0,991	0,062	1,953	3,974	2,049	4,034	-0,067	0,065	7	1,967	3,965	2,031	3,939	-0,030	0,130
170	E02SE	TC	2,031	1,025	1,985	1,027	0,062	1,984	3,932	2,030	3,924	0,038	0,144	8	1,965	3,960	2,032	3,920	-0,030	0,153
182	E031D	TC	1,980	0,998	1,921	0,996	0,061	2,023	3,973	2,064	3,981	0,075	0,154	9	1,936	3,960	2,042	3,928	-0,086	0,167
180	E031E	TC	1,985	1,000	2,007	1,031	0,062	2,030	4,030	2,068	3,909	0,030	0,113	10	1,990	4,042	2,094	4,023	-0,059	0,174
184	E03SD	TC	2,056	1,013	1,967	1,000	0,062	1,960	3,978	2,049	4,030	-0,058	0,068	11	1,982	4,046	2,105	4,017	-0,077	0,203
178	E03SE	TC	2,040	1,027	1,972	1,028	0,062	1,975	3,924	2,044	3,920	0,028	0,178	12	2,007	4,057	2,097	4,022	-0,041	0,181
190	E041D	TC	1,974	0,987	1,932	0,989	0,061	2,009	4,017	2,052	4,009	0,000	0,098	13	1,983	4,024	2,075	4,003	-0,057	0,153
188	E041E	TC	1,948	0,998	1,974	1,024	0,062	2,069	4,038	2,042	3,936	0,101	0,156	14	1,981	4,005	2,073	3,976	-0,042	0,180
192	E04SD	TC	2,056	1,014	1,955	0,999	0,062	1,960	3,974	2,061	4,034	-0,054	0,090	15	1,994	4,019	2,095	3,979	-0,030	0,224
186	E04SE	TC	2,050	1,016	1,962	1,024	0,062	1,950	3,935	2,037	3,896	-0,035	0,192	16	2,020	4,044	2,106	4,008	-0,024	0,215
198	E051D	TC	1,991	0,993	1,925	0,991	0,061	1,991	3,993	2,060	4,001	-0,010	0,122	17	2,008	4,029	2,092	3,973	-0,014	0,224
196	E051E	TC	1,985	1,000	2,016	1,029	0,061	1,997	3,965	1,967	3,853	0,030	0,085	18	2,031	4,057	2,097	4,010	0,006	0,195
200	E05SD	TC	2,058	1,005	1,966	0,994	0,061	1,911	3,913	2,000	3,956	-0,091	0,045	19	1,983	3,956	2,049	3,904	0,010	0,210
194	E05SE	TC	2,074	1,020	1,978	1,027	0,063	1,959	3,983	2,054	3,956	-0,065	0,160	20	1,997	3,972	2,071	3,927	0,023	0,233
206	E061D	TC	2,002	1,001	1,958	1,003	0,061	1,981	3,961	2,025	3,953	0,000	0,101							
204	E061E	TC	1,990	1,008	2,021	1,048	0,062	2,009	3,966	1,978	3,814	0,053	0,154	MED1	1,987	3,996	2,061	3,964	-0,022	0,167
208	E06SD	TC	2,052	1,013	1,972	1,002	0,061	1,932	3,914	2,011	3,957	-0,050	0,066	SIG0	1,021	0,041	0,033	0,040	0,032	0,042
202	E06SE	TC	2,070	1,034	1,992	1,040	0,062	1,931	3,866	2,007	3,844	-0,064	0,185							
214	E071D	TC	2,010	0,999	1,941	1,005	0,061	1,973	3,969	2,043	3,945	-0,024	0,147							
212	E071E	TC	2,000	1,011	2,008	1,039	0,063	2,031	4,018	2,023	3,910	0,044	0,144							
216	E07SD	TC	2,078	1,011	1,968	1,001	0,062	1,924	3,954	2,031	3,994	-0,105	0,070							
210	E07SE	TC	2,093	1,037	2,004	1,040	0,063	1,941	3,918	2,027	3,906	-0,036	0,158							
222	E081D	TC	2,010	1,005	1,950	1,009	0,062	2,005	4,010	2,067	3,994	0,000	0,145							
220	E081E	TC	2,000	1,012	1,995	1,048	0,062	2,015	3,982	2,020	3,845	0,049	0,213							

LWNETA

MEDIDAS DE RESISTENCIA DE FOLHA NAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

AC DIREITA

DIE	POS	R1X	R2X	R1Y	R2Y	RS	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y	LW1X	LW2X	LW1Y	LW2Y	DEL,X	DEL,Y
							METAL											
224	E08SD	TC	2,077	1,017	1,978	1,009	0,062	1,940	3,963	2,037	3,994	-0,081	0,083					
218	E08SE	TC	2,122	1,037	2,013	1,048	0,062	1,899	3,886	2,002	3,845	-0,088	0,172					
230	E09ID	TC	2,063	1,005	1,933	1,004	0,062	1,953	4,010	2,085	4,014	-0,100	0,161					
228	E09IE	TC	2,018	1,011	1,997	1,042	0,062	1,997	3,986	2,018	3,868	0,008	0,182					
232	E09SD	TC	2,079	1,020	1,964	1,012	0,062	1,904	3,919	2,035	3,950	-0,109	0,126					
226	E09SE	TC	2,150	1,035	2,000	1,047	0,063	1,890	3,925	2,031	3,880	-0,143	0,197					
238	E10ID	TC	2,033	0,997	1,933	0,994	0,063	1,998	4,075	2,102	4,087	-0,075	0,117					
236	E10IE	TC	1,992	1,005	1,962	1,034	0,062	2,023	4,010	2,054	3,897	0,036	0,228					
240	E10SD	TC	2,067	1,008	1,937	1,001	0,063	1,981	4,063	2,114	4,091	-0,096	0,139					
234	E10SE	TC	2,108	1,027	1,958	1,028	0,064	1,958	4,019	2,108	4,015	-0,100	0,211					
246	E11ID	TC	2,100	1,002	1,939	1,007	0,063	1,935	4,054	2,075	4,034	-0,175	0,161					
244	E11IE	TC	1,993	1,007	1,961	1,039	0,063	2,035	4,067	2,088	3,941	0,043	0,254					
248	E11SD	TC	2,093	1,012	1,926	1,002	0,064	1,972	4,079	2,143	4,119	-0,128	0,169					
242	E11SE	TC	2,098	1,034	1,971	1,039	0,064	1,967	3,984	2,094	3,973	-0,049	0,230					
254	E12ID	TC	2,019	1,005	1,952	1,005	0,063	2,028	4,075	2,098	4,075	-0,018	0,122					
252	E12IE	TC	1,994	1,012	1,987	1,047	0,064	2,086	4,111	2,094	3,973	0,061	0,228					
256	E12SD	TC	2,070	1,015	1,942	1,007	0,064	1,994	4,067	2,125	4,099	-0,076	0,154					
250	E12SE	TC	2,150	1,038	1,991	1,047	0,064	1,920	3,976	2,073	3,942	-0,133	0,218					
262	E13ID	TC	2,026	1,011	1,961	1,011	0,063	2,021	4,050	2,088	4,050	-0,068	0,128					
260	E13IE	TC	2,017	1,011	1,999	1,040	0,064	2,046	4,083	2,065	3,969	0,010	0,169					
264	E13SD	TC	2,105	1,019	1,958	1,012	0,063	1,945	4,019	2,091	4,046	-0,123	0,140					
258	E13SE	TC	2,150	1,046	2,007	1,046	0,064	1,924	3,946	2,037	3,946	-0,105	0,177					
270	E14ID	TC	2,047	1,010	1,957	1,016	0,063	1,985	4,022	2,076	3,999	-0,052	0,159					
268	E14IE	TC	2,011	1,013	1,988	1,044	0,063	2,034	4,042	2,060	3,922	0,030	0,212					
272	E14SD	TC	2,080	1,019	1,955	1,012	0,063	1,953	3,987	2,078	4,014	-0,079	0,146					
266	E14SE	TC	2,116	1,040	1,985	1,040	0,064	1,953	3,987	2,073	3,949	-0,067	0,201					
278	E15ID	TC	2,032	1,014	1,956	1,020	0,063	1,999	4,006	2,077	3,983	-0,008	0,179					
276	E15IE	TC	2,008	1,015	1,993	1,051	0,064	2,056	4,067	2,071	3,927	0,044	0,231					
280	E15SD	TC	2,096	1,020	1,937	1,013	0,064	1,969	4,047	2,131	4,075	-0,104	0,193					
274	E15SE	TC	2,115	1,043	1,966	1,050	0,064	1,952	3,957	2,099	3,931	-0,054	0,293					
286	E16ID	TC	2,033	1,008	1,947	1,018	0,064	2,028	4,075	2,128	4,055	-0,037	0,192					
284	E16IE	TC	1,993	1,014	1,992	1,045	0,065	2,104	4,135	2,105	4,012	0,072	0,207					
288	E16SD	TC	2,048	1,014	1,943	1,016	0,063	2,000	4,038	2,108	4,031	-0,039	0,192					
282	E16SE	TC	2,120	1,035	1,974	1,049	0,064	1,947	3,988	2,091	3,935	-0,092	0,248					
294	E17ID	TC	2,041	1,018	1,973	1,028	0,064	2,022	4,055	2,092	4,015	-0,010	0,176					
292	E17IE	TC	2,007	1,017	1,983	1,054	0,064	2,057	4,059	2,081	3,916	0,055	0,249					
296	E17SD	TC	2,073	1,024	1,960	1,028	0,064	1,991	4,031	2,106	4,023	-0,048	0,197					
290	E17SE	TC	2,123	1,047	1,992	1,056	0,064	1,960	3,973	2,087	3,939	-0,052	0,254					
302	E18ID	TC	2,039	1,021	1,983	1,028	0,065	2,072	4,138	2,131	4,110	0,066	0,153					
300	E18IE	TC	2,007	1,024	2,004	1,061	0,064	2,073	4,063	2,076	3,921	0,083	0,250					
304	E18SD	TC	2,054	1,027	1,969	1,023	0,063	1,992	3,987	2,080	4,003	-0,004	0,163					
298	E18SE	TC	2,141	1,054	2,024	1,063	0,064	1,989	4,039	2,104	4,005	-0,061	0,212					
310	E19ID	TC	2,065	1,028	1,990	1,037	0,063	1,967	3,952	2,041	3,918	-0,017	0,176					
308	E19IE	TC	2,012	1,032	2,019	1,069	0,064	2,051	4,000	2,044	3,841	0,106	0,251					
312	E19SD	TC	2,071	1,033	1,983	1,031	0,063	1,977	3,964	2,065	3,972	-0,010	0,166					
306	E19SE	TC	2,134	1,056	2,019	1,048	0,064	1,934	3,909	2,044	3,865	-0,041	0,246					
318	E20ID	TC	2,054	1,032	1,995	1,039	0,064	2,009	4,000	2,067	3,973	0,020	0,174					
316	E20IE	TC	2,007	1,030	2,007	1,070	0,064	2,057	4,007	2,057	3,857	0,108	0,284					
320	E20SD	TC	2,075	1,036	1,957	1,027	0,063	1,973	3,953	2,092	3,987	-0,006	0,209					
314	E20SE	TC	2,134	1,059	2,013	1,069	0,064	1,947	3,928	2,067	3,891	-0,030	0,245					

ERR

ERR

APÊNDICE IV

TABELAS DAS MEDIDAS DE OVERLAY

OVERLAY

	NORTE	RB	NORTE	RA	SUL	RB	SUL	RA	LESTE	RB	LESTE	RA	DESTE	RB	DESTE	RA	NORTE	SUL	LESTE	DESTA	SHIFT	XSHIFT	YTETA	X	TETA	Y	
D01SE																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D01IE																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D01ID																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D01SD																		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D02SE	1591,738	1569,548	1605,972	1598,806	1575,8	1573,99	2,183	2,396	-0,016	-0,005	-0,001	0,013	-0,017	-0,021	-0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D02IE	1608,946	1589,704	1605,842	1587,832	1573,148	1567,976	1580,628	1580,896	-0,013	-0,013	-0,004	0,000	-0,001	-0,006	-0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D02ID	1580,796	1549,878	1590,616	1563,56	1533,552	1561,248	1556,19	1554,88	-0,023	-0,020	0,021	-0,001	-0,005	0,033	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D02SD	1580,72	1557,814	1589,364	1578,338	1566,422	1559,268	1565,66	1547,706	-0,017	-0,008	-0,005	-0,013	-0,013	0,012	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
D03SE	1864,92	1459,474	1588,768	1575,36	1566,874	1571,23	1572,446	1561,634	-0,249	-0,010	0,003	-0,008	-0,389	0,017	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D03IE	1891,248	1426,746	1609,76	1577,354	1583,532	1552,394	1581,268	1564,34	-0,306	-0,016	-0,023	-0,012	-0,435	-0,016	-0,003	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D03ID	1859,922	1424,19	1594,322	1553,884	1563,882	1553,21	1554,494	1548,008	-0,297	-0,030	-0,008	-0,005	-0,402	-0,005	-0,003	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D03SD	1905,084	1409,91	1564,034	1555,768	1558,594	1541,274	1579,434	1549,208	-0,327	-0,006	-0,013	-0,022	-0,481	0,014	-0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D04SE	1603,412	1573,244	1596,864	1589,46	1596,21	1553,95	1601,714	1584,092	-0,022	-0,005	-0,031	-0,013	-0,025	-0,028	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D04IE	1617,004	1557,348	1607,17	1598,684	1608,28	1565,464	1603,334	1573,374	-0,043	-0,006	-0,031	-0,021	-0,055	-0,014	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D04ID	1591,06	1541,982	1593,546	1575,444	1586,018	1542,034	1581,79	1556,602	-0,037	-0,013	-0,033	-0,019	-0,035	-0,021	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D04SD	1602,006	1532,104	1588,162	1577,49	1582,444	1545,73	1587,57	1554,206	-0,051	-0,008	-0,027	-0,027	-0,065	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D05SE	1636,216	1603,002	1629,84	1623,402	1618,654	1571,494	1637,21	1597,186	-0,023	-0,004	-0,034	-0,028	-0,028	-0,009	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D05IE	1653,306	1581,648	1630,97	1623,014	1637,218	1585,988	1632,8	1594,616	-0,049	-0,005	-0,036	-0,024	-0,066	-0,014	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D05ID	1621,764	1568,626	1620,098	1600,536	1621,4	1559,576	1608,468	1575,644	-0,038	-0,014	-0,045	-0,024	-0,037	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D05SD	1620,284	1553,448	1601,544	1590,156	1620,672	1545,634	1638,754	1553,426	-0,048	-0,008	-0,054	-0,059	-0,060	-0,007	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D06SE	1608,25	1620,27	1628,328	1633,146	1625,856	1584,096	1645,486	1576,6	-0,009	-0,003	-0,030	-0,049	-0,008	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D06IE	1614,08	1634,348	1624,102	1622,012	1653,248	1575,356	1655,192	1587,248	-0,014	-0,003	-0,054	-0,047	-0,025	-0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D06ID	1674,024	1537,226	1627,388	1613,074	1662,174	1559,886	1656,006	1558,394	-0,098	-0,010	-0,072	-0,069	-0,131	-0,004	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D06SD	1639,494	1589,244	1627,636	1627,934	1631,002	1576,9	1744,49	1593,2	-0,035	0,000	-0,038	-0,166	-0,032	0,192	-0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D07SE	1632,986	1425,38	1622,616	1610,53	1622,888	1594,398	1628,834	1592,352	-0,005	-0,008	-0,020	-0,026	-0,005	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D07IE	1666,312	1598,412	1639,76	1623,264	1703,63	1534,988	1640,548	1600,284	-0,046	-0,011	-0,116	-0,028	-0,052	-0,133	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D07ID	1618,578	1596,942	1628,04	1615,128	1621,566	1585,31	1619,248	1591,032	-0,015	-0,009	-0,026	-0,019	-0,010	-0,010	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D07SD	1651,438	1578,106	1623,302	1617,27	1643,68	1560,838	1652,378	1583,794	-0,051	-0,006	-0,058	-0,047	-0,068	-0,017	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D08SE	1647,888	1615,746	1630,564	1609,29	1613,694	1605,564	1616,322	1616,326	-0,022	-0,015	-0,006	0,000	-0,011	-0,009	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D08IE	1666,792	1622,024	1650,06	1622,03	1632,368	1582,266	1642,714	1631,648	-0,030	-0,019	-0,048	-0,007	-0,016	-0,001	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D08ID	1646,22	1588,246	1669,072	1583,738	1600,776	1619,312	1612,286	1617,218	-0,041	-0,059	0,013	0,003	0,028	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D08SD	1707,272	1538,296	1628,25	1595,976	1639,322	1567,982	1625,556	1598,848	-0,115	-0,022	-0,050	-0,019	-0,139	-0,047	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D09SE	1656,278	1631,012	1655,304	1623,082	1611,882	1628,598	1622,178	1639,444	-0,013	-0,022	0,012	0,012	0,013	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D09IE	1669,02	1604,888	1635,394	1606,056	1636,122	1597,328	1628,162	1620,738	-0,043	-0,033	-0,027	-0,005	-0,014	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D09ID	1643,488	1602,4	1664,752	1595,82	1603,482	1613,656	1622,926	1620,456	-0,029	-0,047	0,007	-0,002	0,028	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D09SD	1645,064	1597,736	1636,404	1592,402	1602,044	1615,262	1629,49	1617,846	-0,032	-0,030	0,009	-0,008	0,003	0,026	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D10SE	1672,87	1616,12	1659,23	1617,75	1625,406	1614,168	1623,354	1625,564	-0,038	-0,008	0,002	-0,015	-0,015	-0,014	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D10IE	1766,632	1542,442	1662,73	1604,038	1701,32	1548,544	1621,576	1611,278	-0,148	-0,040	-0,104	-0,007	-0,162	-0,146	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D10ID	1697,77	1535,314	1661,908	1601,442	1621,232	1609,566	1624,328	1619,242	-0,099	-0,042	-0,099	-0,004	-0,086	-0,008	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D10SD	1685,314	1579,564	1662,03	1586,334	1621,708	1594,03	1624,346	1617,088	-0,071	-0,052	-0,019	-0,005	-0,030	-0,022	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D11SE	1777,54	1506,922	1643,56	1608,826	1709,014	1545,39	1631,12	1619,164	-0,184	-0,024	-0,113	-0,008	-0														

B15SE	1907,39	1400,3	1636,326	1591,302	1714,938	1486,33	1613,338	1593,324	-0,346	-0,031	-0,164	-0,014	-0,471	-0,224	-0,004	-0,002
D15IE	1909,778	1393,238	1642,182	1582,892	1776,99	1434,8	1622,368	1589,806	-0,347	-0,041	-0,242	-0,023	-0,459	-0,329	-0,004	-0,003
B15ID	1872,45	1407,334	1649,658	1593,356	1713,19	1487,984	1624,65	1598,04	-0,321	-0,039	-0,161	-0,019	-0,424	-0,214	-0,003	-0,002
D15SD	1906,244	1389,216	1644,9	1586,3	1747,428	1472,454	1623,84	1586,412	-0,351	-0,040	-0,192	-0,026	-0,466	-0,249	-0,004	-0,002
D16SE	1887,166	1411,332	1629,094	1581,826	1669,96	1516,31	1622,03	1601,91	-0,315	-0,033	-0,111	-0,014	-0,423	-0,145	-0,003	-0,001
B16IE	1823,59	1427,598	1645,552	1578,03	1677,41	1495,792	1610,384	1594,512	-0,273	-0,047	-0,130	-0,011	-0,340	-0,179	-0,003	-0,001
B16ID	1848,436	1418,374	1645,404	1597,468	1653,342	1540,398	1605,118	1583,61	-0,299	-0,046	-0,081	-0,015	-0,379	-0,098	-0,003	-0,001
D16SD	1875,018	1398,574	1653,468	1593,316	1698,076	1509,522	1622,974	1595,5	-0,326	-0,041	-0,132	-0,019	-0,429	-0,170	-0,003	-0,001
D17SE	1660,646	1545,202	1635,036	1581,984	1613,328	1575,368	1598,83	1594,98	-0,082	-0,037	-0,027	-0,003	-0,067	-0,037	-0,001	-0,000
D17IE	1776,106	1456,7	1675,334	1551,858	1676,758	1510,848	1609,63	1600,04	-0,222	-0,085	-0,118	-0,007	-0,205	-0,167	-0,002	-0,001
D17ID	1699,12	1519,23	1682,006	1585,984	1603,018	1593,982	1607,87	1599,82	-0,127	-0,080	-0,066	-0,004	-0,070	-0,001	-0,001	-0,000
D17SD	1676,558	1403,884	1660,276	1575,998	1642,47	1555,74	1624,36	1603,948	-0,322	-0,058	-0,061	-0,014	-0,396	-0,070	-0,003	-0,001
B18SE	1631,8	1571,904	1629,558	1579,38	1530,918	1651,064	1597,198	1601,824	-0,043	-0,042	-0,087	-0,003	-0,000	0,126	-0,000	0,001
B18IE	1675,21	1548,608	1707,812	1526,776	1601,616	1548,752	1594,01	1587,6	-0,088	-0,125	-0,039	-0,005	0,054	-0,051	0,000	-0,000
B18ID	1654,762	1539,16	1786,416	1488,02	1577,03	1610,832	1604,156	1604,174	-0,068	-0,205	0,024	0,000	0,205	0,036	0,002	0,000
D18SD	1655,91	1569,152	1687,034	1567,106	1597,486	1618,338	1600,786	1604,392	-0,060	-0,081	0,015	0,003	0,032	0,018	0,000	0,000
D19SE	1624,392	1585,786	1635,494	1586,438	1585,476	1644,54	1599,868	1606,414	-0,028	-0,035	0,058	0,005	0,010	0,080	0,000	0,001
D19IE	1637,532	1576,07	1682,93	1549,478	1593,618	1577,712	1598,204	1600,908	-0,043	-0,072	-0,011	0,002	0,074	-0,020	0,001	-0,000
D19ID	1632,34	1589,738	1715,502	1532,006	1542,608	1656,554	1600,77	1609,61	-0,030	-0,128	0,082	0,006	0,147	0,113	0,001	0,001
B19SD	1652,712	1570,516	1761,174	1482,212	1584,508	1614,966	1601,06	1602,242	-0,057	-0,193	0,022	0,001	0,204	0,031	0,002	0,000
D20SE	1633,678	1597,482	1631,29	1592,924	1574,12	1617,314	1602,216	1612,89	-0,026	-0,027	0,031	0,008	0,002	0,036	0,000	0,000
D20IE	1644,848	1588,102	1687,394	1540,724	1593,272	1583,458	1606,418	1605,264	-0,039	-0,102	-0,007	-0,001	0,094	-0,009	0,001	-0,000
D20ID	1628,1	1594,42	1695,484	1533,268	1559,02	1628,662	1588,952	1603,544	-0,024	-0,115	0,051	0,011	0,136	0,060	0,001	0,000
D20SD	1645,954	1580,05	1669,056	1571,382	1568,13	1630,806	1591,924	1604,884	-0,046	-0,067	0,044	0,009	0,032	0,053	0,000	0,000
E01SE	1575,528	1581,03	1601,724	1592,212	1552,626	1547,788	1569,618	1556,042	0,004	0,023	-0,004	-0,010	-0,028	0,010	-0,000	0,000
E01IE	1563,472	1572,812	1567,338	1584,502	1547,152	1545,92	1540,312	1567,848	0,007	0,012	0,006	0,020	-0,008	-0,022	-0,000	-0,000
E01ID	1592,7	1565,384	1594,15	1565,208	1554,998	1550,916	1566,604	1568,234	-0,020	-0,021	-0,003	0,001	0,002	-0,006	0,000	-0,000
E01SD									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E02SE	1574,656	1571,798	1569,116	1569,308	1558,736	1551,402	1558,358	1544,502	-0,002	0,000	-0,006	-0,010	-0,003	0,007	-0,000	0,000
E02IE	1569,214	1581,35	1568,694	1570,594	1557,94	1564,862	1561,832	1595,586	0,009	0,001	0,005	0,024	0,011	-0,029	0,000	-0,000
E02ID	1603,41	1538,708	1592,026	1555,686	1582,274	1520,316	1571,07	1557,468	-0,032	-0,027	-0,047	-0,010	-0,009	-0,055	-0,000	-0,000
E02SD	1594,732	1564,36	1609,25	1562,348	1532,318	1578,514	1587,74	1586,96	-0,020	-0,033	0,019	-0,001	0,020	0,030	0,000	0,000
E03SE	1591,172	1591,704	1581,524	1581,838	1581,216	1571,646	1578,974	1593,782	0,000	0,000	-0,007	0,011	0,000	-0,027	0,000	-0,000
E03IE	1588,746	1586,806	1587,368	1586,648	1586,812	1584,46	1586,5	1596,288	-0,001	-0,001	-0,002	0,007	-0,001	-0,013	-0,000	-0,000
E03ID	1628,686	1572,928	1607,926	1568,352	1648,96	1501,676	1596,22	1595,384	-0,040	-0,029	-0,109	-0,001	-0,017	-0,163	-0,000	-0,001
E03SD	1614,436	1539,81	1603,974	1567,342	1609,976	1533,494	1594,918	1718,718	-0,039	-0,026	-0,056	0,081	0,019	-0,205	-0,000	-0,002
E04SE	1614,374	1627,788	1602,384	1610,77	1596,19	1581,83	1637,288	1597,374	0,009	0,006	-0,012	-0,028	0,005	0,024	0,000	0,000
E04IE	1610,09	1612,964	1604,432	1605,482	1599,038	1583,708	1604,204	1596,678	-0,002	-0,001	-0,011	-0,007	0,004	-0,006	0,000	-0,000
E04ID	1725,564	1517,794	1624,514	1589,806	1702,892	1478,192	1632,802	1603,382	-0,145	-0,025	-0,163	-0,020	-0,180	-0,215	-0,001	-0,002
E04SD	1630,944	1565,272	1605,9	1577,533	1631,664	1546,186	1611,488	1578,62	-0,046	-0,020	-0,061	-0,023	-0,039	-0,057	0,000	-0,000
E05SE	1595,844	1633,412	1599,94	1599,5	1609,148	1579,792	1635,87	1767,324	0,026	-0,000	-0,021	0,082	0,040	-0,155	0,000	-0,001
E05IE	1609,878	1620,024	1618,34	1623,308	1602,906	1585,062	1622,27	1610,654	0,007	0,003	-0,013	-0,008	0,005	-0,007	0,000	-0,000
E05ID	1730,326	1514,39	1620,454	1595,526	1733,526	1458,736	1685,888	1544,34	-0,151	-0,018	-0,200	-0,098	-0,200	-0,152	-0,002	-0,001
E05SD	1717,236	1512,138	1622,358	1582,784	1670,536	1531,22	1643,432	1587,348	-0,142	-0,028	-0,098	-0,039	-0,171	-0,089	-0,001	-0,001
E06SE	1590,354	1662,336	1616,402	1628,312	1631,628	1591,954	1656,192	1580,376	0,050	0,008	-0,028	-0,053	0,062	0,038	0,001	0,000
E06IE	1608,63	1676,094	1618,32	1652,422	1631	1613,41	1663,866	1614,916	0,045	0,023	-0,012	-0,033	0,034	0,031	0,000	0,000
E06ID	1718,536	1527,482	1638,906	1610,618	1739,892	1489,212	1742,272	1495,982	-0,133	-0,020	-0,178	-0,173	-0,171	-0,066	-0,001	-0,000
E06SD	1697,884	1539,026	1622,824	1602,118	1709,596	1503,896	1749,366	1511,994	-0,110	-0,014	-0,145	-0,162	-0,143	0,026	0,001	0,000
E07SE	1550,246	1712,376	1603,854	1620,748	1636,936	1607,866	1770,838	1494,96	0,112	0,012	-0,020	-0,191	0,150	0,257	0,001	0,002
E07IE	1573,072	1683,094	1621,34	1639,176	13,218	593,87	1645,588	1607,816	0,075	0,012	####	-0,024	0,094	0,001		
E07ID	1724,954	1552,652	1627,192	1605,642	1755,43	1478,82	1761,08	1516,1	-0,118	-0,015	-0,196	-0,168	-0,154	-0,042	-0,001	-0,000
E07SD	1722,348	1538,462	1621,184	1603,94	1730,886	1514,584	1783,252	1488,064	-0,125	-0,012	-0,148	-0,200	-0,169	0,077	-0,001	0,001
E08SE	1599,372	1670,126	1612,792	1624,018	1629,384	1600,484	1680,528	1594,216	0,049	0,008	-0,020	-0,059	0,061	0,058	0,000	0,000
E08IE	1629,166	1635,468	1615,236	1620,056	1616,366	1596,736	1640,426	1660,972	0,004	0,003	-0,014	0,014	0,001	-0,041	0,000	-0,000
E08ID	1772,09	1509,908	1630,162	1599,15	1768,438	1479,868	1665,236	1589,662	-0,179	-0,022	-0,202	-0,052	-0,236	-0,225	-0,002	-0,002
E08SD	1734,048	1525,08	1624,1	1597,34	1701,6	1542,158	1693,322	1566,44	-0,143	-0,019	-0,110	-0,086	-0,186	-0,035	-0,001	-0,000
E09SE	1660,47	1638,502	1623,18	1620,498	1648,628	1613,568	1650,652	1608,704	-0,015	-0,002	-0,024	-0,029	-0,019	0,007	-0,000	0,000
E09IE	1643,87	1623,888	1627,24	1621,098	1628,5	1605,59	1627,5	1625,814	-0,013	-0,004	-0,016	-0,001	-0,014	-0,022	-0,000	-0,000
E09ID	1831,634	1463,98	1635,228	1590,796	1777,87	1456,384	1636,518	1617,352	-0,251	-0,03						

E106E	1716,028	1560,328	1622,844	1602,548	1721,53	1520,99	1645,156	1616,252	-0,107	-0,014	-0,141	-0,020	-0,139	-0,182	-0,001	-0,001
E101E	1673,654	1587,424	1638,75	1611,278	1684,106	1542,202	1642,416	1632,784	-0,071	-0,019	-0,079	-0,004	-0,079	-0,139	-0,001	-0,001
E101D	1927,31	1433,596	1534,206	1604,078	1848,946	1418,416	1637,042	1598,32	-0,328	-0,035	-0,302	-0,027	-0,439	-0,413	-0,004	-0,003
E105D	1748,554	1522,292	1642,022	1583,142	1650,032	1545,93	1634,7	1624,264	-0,165	-0,041	-0,059	-0,007	-0,186	-0,078	-0,001	-0,001
E111E	1758,28	1504,234	1630,296	1604,47	1830,268	1446,924	1644,66	1598,046	-0,175	-0,018	-0,264	-0,032	-0,236	-0,348	-0,002	-0,003
E111C	1768,52	1490,074	1630,74	1600,884	1820,782	1451,132	1621,898	1586,536	-0,189	-0,020	-0,251	-0,025	-0,253	-0,339	-0,002	-0,003
E111D	1966,498	1381,072	1643,502	1590,696	1915,03	1371,574	1440,42	1589,828	-0,392	-0,037	-0,378	-0,035	-0,533	-0,514	-0,004	-0,004
E115D	1878,182	1409,532	1627,364	1576,29	1776,404	1451,958	1638,754	1601,264	-0,317	-0,036	-0,226	-0,028	-0,422	-0,300	-0,003	-0,002
E122E	1812,876	1454,648	1621,152	1584,8	1920,08	1380,464	1442,89	1593,066	-0,247	-0,024	-0,371	-0,035	-0,332	-0,305	-0,003	-0,004
E121E	1833,816	1442,64	1637,136	1595,816	1884,954	1386,162	1632,232	1598,852	-0,264	-0,028	-0,343	-0,023	-0,354	-0,481	-0,003	-0,004
E121D	2057,5	1329,386	1643,508	1582,04	2019,384	1332,184	1635,776	1585,01	-0,484	-0,043	-0,465	-0,034	-0,662	-0,644	-0,005	-0,005
E126D	1974,862	1364,698	1630,75	1575,382	1884,734	1392,92	1635,324	1590,854	-0,405	-0,039	-0,337	-0,031	-0,556	-0,459	-0,004	-0,004
E135E	1845,83	1441,93	1628,184	1583,082	1931,782	1377,208	1635,49	1587,516	-0,276	-0,032	-0,380	-0,034	-0,366	-0,319	-0,003	-0,004
E131E	1841,218	1445,874	1632,19	1590,998	1853,886	1404,376	1632,2	1602,238	-0,285	-0,028	-0,309	-0,020	-0,355	-0,433	-0,003	-0,003
E131D	2043,85	1342,508	1646,198	1584,59	2000,924	1328,568	1638,34	1590,014	-0,464	-0,041	-0,461	-0,034	-0,634	-0,641	-0,005	-0,005
E135D	1889,392	1354,882	1641,392	1582,798	1939,852	1369,192	1638,148	1591,538	-0,421	-0,040	-0,385	-0,032	-0,571	-0,529	-0,005	-0,004
E144E	1892,374	1407,876	1642,066	1585,252	1843,832	1403,742	1629,43	1589,636	-0,331	-0,040	-0,310	-0,028	-0,437	-0,423	-0,004	-0,003
E141E	1857,458	1415,318	1651,04	1595,55	1762,73	1450,13	1623,814	1599,844	-0,301	-0,038	-0,219	-0,017	-0,395	-0,304	-0,003	-0,002
E141D	2084,256	1320,18	1649,012	1580,59	1906,586	1363,224	1624,042	1585,714	-0,505	-0,048	-0,381	-0,027	-0,686	-0,531	-0,006	-0,004
E145D	2011,634	1340,506	1631,51	1571,48	1878,306	1386,158	1628,206	1598,98	-0,446	-0,042	-0,339	-0,027	-0,666	-0,468	-0,005	-0,004
E135E	1873,294	1396,418	1634,53	1580,55	1766,42	1441,31	1625,14	1588,92	-0,332	-0,039	-0,233	-0,026	-0,439	-0,311	-0,004	-0,003
E151E	1829,804	1442,402	1637,532	1579,914	1685,244	1500,012	1619,6	1603,484	-0,263	-0,040	-0,132	-0,011	-0,334	-0,181	-0,003	-0,001
E151D	2087,672	1301,56	1653,256	1582,746	1877,998	1369,832	1637,064	1600,236	-0,527	-0,049	-0,361	-0,026	-0,717	-0,503	-0,006	-0,004
E135D	1985,232	1348,864	1650,018	1571,932	1742,514	1445,9	1637,472	1601,742	-0,427	-0,054	-0,212	-0,024	-0,559	-0,282	-0,004	-0,002
E145E	1832,254	1417,878	1631,618	1589,22	1701,29	1492,042	1602,628	1572,888	-0,291	-0,044	-0,151	-0,022	-0,370	-0,194	-0,003	-0,002
E161E	1762,462	1476,624	1660,34	1579,17	1623,44	1545,988	1606,48	1601,504	-0,197	-0,054	-0,003	-0,213	-0,078	-0,002	-0,001	-0,001
E161D	2035,158	1308,44	1645,002	1563,874	1797,814	1402,9	1603,926	1577,626	-0,499	-0,058	-0,287	-0,019	-0,662	-0,402	-0,005	-0,003
E145D	1828,232	1430,744	1647,074	1564,108	1654,348	1512,878	1607,862	1588,786	-0,265	-0,057	-0,101	-0,013	-0,312	-0,131	-0,003	-0,001
E175E	1803,702	1432,912	1636,454	1586,324	1654,366	1518,94	1598,12	1577,932	-0,262	-0,050	-0,099	-0,015	-0,318	-0,126	-0,003	-0,001
E171E	1644,176	1540,386	1643,74	1572,83	1577,918	1579,536	1600,548	1596,958	-0,074	-0,049	0,001	-0,003	-0,037	0,006	-0,000	0,000
E171D	1989,12	1333,604	1645,174	1571,434	1695,844	1461,922	1594,43	1568,842	-0,451	-0,052	-0,173	-0,019	-0,599	-0,231	-0,005	-0,002
E175D	1720,408	1490,982	1645,784	1539,34	1628,024	1531,138	1601,566	1585,77	-0,161	-0,061	-0,070	-0,011	-0,151	-0,088	-0,001	-0,001
E185E	1635,444	1556,28	1690,42	1516,04	1571,956	1606,054	1583,692	1581,518	-0,057	-0,125	0,025	-0,002	0,102	0,040	0,001	0,000
E181E	1623,64	1576,73	1722,556	1521,52	1528,446	1643,49	1593,582	1611,438	-0,033	-0,138	0,083	0,013	0,157	0,105	0,001	0,001
E181D	1738,238	1498,784	1690,984	1535,182	1620,19	1521,802	1590,12	1581,45	-0,168	-0,110	-0,073	-0,066	-0,087	-0,101	-0,001	-0,001
E185D	1636,53	1540,256	1638,264	1538,278	1580,558	1555,192	1595,568	1591,416	-0,069	-0,072	-0,019	-0,003	0,004	-0,024	0,000	-0,000
E195E	1623,45	1586,784	1744,874	1486,19	1504,74	1547,684	1587,022	1602,128	-0,026	-0,183	0,034	0,011	0,235	0,002	0,000	0,000
E191E	1612,97	1584,99	1700,758	1536,74	1474,324	1714,082	1589,416	1618,284	-0,020	-0,113	0,172	0,020	0,140	0,228	0,001	0,002
E191D	1642,29	1558,43	1832,254	1451,884	1560,67	1591,218	1585,434	1592,36	-0,064	-0,262	0,023	0,005	0,303	0,024	0,002	0,000
E195D	1632,476	1562,89	1849,9	1399,874	1527,88	1640,952	1596,156	1607,738	-0,049	-0,315	0,082	0,008	0,398	0,110	0,003	0,001
E205E	1642,396	1566,01	1748,512	1467,336	1548,974	1617,218	1596,412	1600,176	-0,055	-0,202	0,050	0,003	0,221	0,071	0,002	0,001
E201E	1629,202	1593,426	1633,434	1582,118	1569,77	1610,972	1585,346	1601,796	-0,025	-0,036	0,030	0,012	0,017	0,027	0,000	0,000
E201D	1872,684	1402,07	1635,478	1565,288	1698,782	1464,378	1593,246	1581,454	-0,330	-0,050	-0,174	-0,010	-0,419	-0,246	-0,003	-0,002
E205D	1628,218	1562,962	1645,948	1540,47	1547,832	1620,66	1586,712	1602,48	-0,046	-0,075	0,053	0,011	0,043	0,062	0,000	0,000

APÊNDICE V

PROGRAMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DA MEDIDA DE LARGURA DE LINHA

```

10 KEY 5,"SHELL"+CHR$(34)+"TYPE D
20 'LOCATE 21,10: SHELL"TYPE D21XA.DAT"
30 'LOCATE 21,10: SHELL"TYPE D21YA.DAT"
40 CLS: KEY OFF: ON ERROR GOTO 2330
50 CLEAR ,60000!: IBINIT1=60000!: IBINIT2=IBINIT1+3 : BLOAD "bib.m",IBINIT1
60 MENS0$=" [ P ] - PARA O PROGRAMA "
70 MENS1$=" [ N ] - NAO INICIALIZA OS INSTRUMENTOS"
80 MENS2$=" <ESPAÇO> - CONTINUA O PROGRAMA "
90 LOCATE 20, 5: PRINT "INTRUÇÕES: ";MENS0$
100 LOCATE 21,16: PRINT MENS1$ '
110 LOCATE 22,16: PRINT MENS2$ '
120 WHILE P$=""
130 P$=INKEY$
140 WEND
150 CLS
160 BR$=SPACE$(20): LBR$=SPACE$(50) ' BLOAD"tela
170 ' ****
180 ' ***
190 ' *** PROGRAMA .....: PROGRAMA I X V (GPIB-PC) COM A UTILIZACAO ****
200 ' *** DOS EQUIPAMENTOS: D3478A, D3478B,D4145B ****
210 ' ***
220 ' *** PROGRAMADORES : MARCELO DE J. FERMINO ****
230 ' ***
240 ' *** DATA .....: 16/05/1990 LACAM IM ****
250 ' ***
260 ' ****
270 -
280 -
290 ' INICIALIZACAO DO GPIBO
300 -
310 -
320 ' CHAMADA DAS ROTINAS GPIB-PC
330 -
340 CALL IBINIT1(IBFIND,IBTRG,IBCLR,IBPCT,IBSIC,IBLOC,IBPPC,IBBNA,IBONL,IBRSC,
           IBSRE,IBRSV,IBPAD,IBSAD,IBIST,IBDMA,IBEOS,IBTMO,IBEOT,IBRDF,
           IBWRTF,IBTRAF)
350 CALL IBINIT2(IGTS ,IBCAC ,IBWAIT,IBPOKE,IBWRT ,IBWRTA,IBCMD,IBCMDA,IBRD,
           IBRDA,IBSTOF,IBRPP ,IBRSP ,IBDIAG,IBXTRC,IBRDI,IBWRTI,IBRDIA,
           IBWRTRIA,IBSTAT%,IBERR%,IBCNT%)
360 -
370 -
380 ' INICIO DA ATIVACAO DOS EQUIPAMENTOS NA INTERFACE
390 -
400 ' VARIAVEIS COMUNS
410 COMMON IBSTAT%,IBERR%,IBCNT%
420 -
430 -
440 ' TESTE DE LOCALIZACAO DA INTERFACE GPIBO E DOS EQPTOS
450 -
460 DVN$="GPIBO" : GOSUB 850: GPIBO% =FIND0%      ' LOCALIZA A PLACA GPIB
470 DVN$="D3478A": GOSUB 850: D3478A% =FIND0%      ' LOCALIZA OS EQPTOS NA PLACA
480 DVN$="D3478B": GOSUB 850: D3478B% =FIND0%      ' LOCALIZA OS EQPTOS NA PLACA
490 DVN$="D4145B": GOSUB 850: D4145B% =FIND0%      ' LOCALIZA OS EQPTOS NA PLACA
500 '

```

```

510 IF P$="P" OR P$="p" THEN STOP
520 IF P$="N" OR P$="n" THEN 1760
530 '
540 '
550 '          ROTINA DE INICIALIZACAO DA INTERFACE GPIB-PC
560 '
570 '
580 '
590 '
600 CALL IBSIC (GPIBOX)           : MENSAGEM DE ERRO
610 CALL IBLOC (GPIBOX)          : ENVIA INTERFACE CLEAR
620 'CALL IBSRE (GPIBOX,V%)      : COLOCA EM MODO LOCAL
630 LOCATE 23,20
640 IF IBSTAT% < 0 THEN GOSUB 1410 ELSE PRINT "TESTE DA PLACA OK !!!!";BR$
650 '
660 '
670 '          TESTE FISICO DOS EQUIPAMENTOS
680 '
690 DISPO%=D3478A%: GOSUB 870          'INICIALIZACAO
700 DISPO%=D3478B%: GOSUB 870          'INICIALIZACAO
710 DISPO%=D4145B%: GOSUB 870          'INICIALIZACAO
720 '
730 '          ---- FIM DA INICIALIZACAO ----
740 '
750 '          %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
760 '          %
770 '          %          INICIO DO PROGRAMA DO USUARIO %
780 '          %          A PARTIR DA LINHA 1240 !! %
790 '          %
800 '          %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
810 IF FIM$<>"FIM" THEN 1760 ELSE RETURN
820 '
830 '
840 '          LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E DA PLACA
850 '
860 DVNAME$=DVN$: CALL IBFIND (DVNAME$,FINDO%): GOSUB 1270 : RETURN
870 '
880 '
890 '          INICIALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS
900 '
910 IF DISPO%<0 THEN 950          'ROTINA DE DETECAO DE ERRO DE ESCRITA
920 CALL IBCLR(DISPO%): GOSUB 1410  'INICIALIZA O EQPTO
930 CALL IBLOC(DISPO%): GOSUB 1410  'COLOCA-O EM MODO LOCAL
940 RETURN
950 '
960 '
970 '          ROTINA DE DETECAO DE ERRO DE ESCRITA
980 '
990 LOCATE 23,15:PRINT "Impossivel comunicar-se com o equipamento";DISPO%;BEEP
1000 RETURN

```

```

1010 '-----  

1020 '  

1030 '      ESCRITA NOS EQUIPAMENTOS  

1040 '  

1050 IF WRT$="" OR DISPO%<>0 THEN 950 'ROTINA DE DETECAO DE ERRO DE ESCRITA  

1060 REM LOCATE 1,60: PRINT DISPO%;WRT$  

1070 CALL IBWRT(DISP0%,WRT$): GOSUB 1410 'ESCREVE A FUNCAO WRT$  

1080 RETURN  

1090 '  

1100 '  

1110 '      FINALIZACAO DOS TESTES  

1120 '  

1130 FIM$="FIM": GOSUB 650  

1140 '  

1150 '      LIMPA A INTERFACE E A COLOCA EM MODO LOCAL  

1160 '  

1170 DVN$="GPIBO" : GOSUB 850: GPIB0% =FIND0%      ' LOCALIZA A PLACA GPIB  

1180 GOSUB 1270: V%<0  

1190 CALL IBSIC (GPIB0%)                                'ENVIA INTERFACE CLEAR  

1200 CALL IBLOC (GPIB0%)                                'COLOCA EM MODO LOCAL  

1210 CALL IBSRE (GPIB0%,V%)                            'COLOCA EM MODO LOCAL  

1220 '  

1230 '  

1240 '      FIM DO PROGRAMA  

1250 '  

1260 END  

1270 '  

1280 '  

1290 '      LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS NA INTERFACE  

1300 '  

1310 '  

1320 REM CALL IBFIND (DVNAME$,GPIB0%)  

1330 LOCATE 23,20  

1340 IF FIND0%<>0 THEN MENS$="IBFIND ERROR" ELSE MENS$="OK !!! - DEFINIDO"  

1350 MENS$=MENS$+SPACE$(10)  

1360 LOCATE 23,20: PRINT MENS$;DVNAME$  

1370 RETURN  

1380 '  

1390 '      TESTES DE PROVAVEIS ERROS DO GPIB  

1400 '  

1410 REM PRINT HEX$(IBSTAT%),IBERR%  

1420 IF IBERR%<>0 THEN GOTO 1480 ELSE DISP$=SPACE$(10): RETURN  

1430 '  

1440 '  

1450 '      MENSAGENS DE ERROS DO GPIB  

1460 '  

1470 '  

1480 RESTORE  

1490 FOR D=1 TO 13  

1500 READ ER%,EST$
```

```

1510      IF ER% = IBERR% THEN 1530 ELSE EST$ = "GPIB ERROR - "+STR$(IBERR%)  

1520      NEXT  

1530      EAUX$ = EST$  

1540      LOCATE 23,5: PRINT CHR$(7); "MENSAGEM: "; EAUX$; DISPO%  

1550      WHILE INKEY$ = "": WEND : GOTO 40  

1560      '  

1570      '  

1580      TABELA DE ERROS DOS EQUIPAMENTOS  

1590      '  

1600      '  

1610      DATA 1, " Function requires GPIB-PC to be CIC      "  

1620      DATA 2, " No Listener on write function      "  

1630      DATA 3, " GPIB-PC NOT addressed correctly      "  

1640      DATA 4, " Invalid argument to function call      "  

1650      DATA 5, " GPIB-PC not System Controller as required      "  

1660      DATA 6, " I/O operation aborted      "  

1670      DATA 7, " Non-existent GPIB-PC board      "  

1680      DATA 10, " I/O started before previous operation      "  

1690      DATA 11, " No capacility for operation      "  

1700      DATA 12, " File system error      "  

1710      DATA 14, " Command error during device call      "  

1720      DATA 15, " Serial Poll status byte lost      "  

1730      DATA 16, " SQR stuck in on position      "  

1740      '  

1750      'XXXXXXXXX      FIM DAS SUBROTINAS DO GPIB      XXXXXXXX  

1760      '  

1770      '  

1780      '***  

1790      '***      INICIO DO PROGRAMA DO USUARIO      ***  

1800      '***  

1810      '  

1820      SCREEN 2: KEY OFF: T=.5: TE$ = "A": FT=10000: V1$=SPACE$(13):V2$=V1$:ME$="N"  

1830      D$=MID$(DATE$,4,2)+"/"+LEFT$(DATE$,2)+"/"+RIGHT$(DATE$,4): FA=FT  

1840      LINE (0,20)-(639,189),,B: LINE (0,169)-(639,169): 'LINE (0,20)-(639,20)  

1850      LINE (4,22)-(635,187),,B  

1860      LOCATE 2, 1: PRINT "C T I / I M - L A C A M "  

1870      LOCATE 2,63: PRINT "DATA .:";D$  

1880      LOCATE 1,63: PRINT "HORAS.:"  

1890      LOCATE 5,25: PRINT "PROGRAMA DE AQUISICAO I X V"  

1900      'WHILE INKEY$ = "": WEND  

1910      LOCATE 23, 5: PRINT LBR$: GOSUB 2260: CLOSE  

1920      LOCATE 8, 5: PRINT "01 - TEMPO DE MEDIDA .:";T;"seg(s)";BR$  

1930      LOCATE 10, 5: PRINT "02 - ESTRUTURA (A/C) .: ";TE$;BR$  

1940      LOCATE 12, 5: PRINT "03 - NUMERO DO DIE .: ";ND$;BR$  

1950      LOCATE 14, 5: PRINT "04 - FATOR DE ESCALA .: ";FT;BR$  

1960      LOCATE 14,50: PRINT "05 - MED. DIRETA(S/N) : ";ME$  

1970      IF ND$ = "" THEN GOSUB 2230: GOTO 1970  

1980      IF FT <= 0 THEN GOSUB 2240: GOTO 1980  

1990      LOCATE 23, 5: PRINT "MENSAGEM: Deseja alterar algum parametro (s/N) ";  

2000      LOCATE 23,60: PRINT "[ # ]"

```

```

2010 LOCATE 23,62: INPUT "",CONF$           '
2020 IF CONF$="S" OR CONF$="s"             THEN 2040
2030 IF CONF$="N" OR CONF$="n" OR CONF$="" THEN 2110 ELSE 2010
2040 LOCATE 23, 5: PRINT "MENSAGEM: Informe o item a alterar (0=fim)";BR$
2050 LOCATE 23,60: PRINT "[ # ]"
2060 LOCATE 23,62: INPUT "",NA$
2070 NA=VAL(NA$)
2080 IF NA=0 THEN 2110
2090 ON NA GOSUB 2210,2220,2230,2240,2250
2100 GOTO 2040
2110 '
2120 ' CONFERE OS DADOS
2130 '
2140 IF TE$="A" THEN SUF$="B": GOTO 2530
2150 IF TE$="C" THEN SUF$="A": GOTO 2640 ELSE GOSUB 2220: GOTO 2140
2160 IF NA$="" THEN GOSUB 2230: GOTO 2160
2170 GOSUB 2260: GOTO 2530
2180 '
2190 ' ROTINA DE ENTRADA DE DADOS
2200 '
2210 LOCATE 8,29: INPUT "",T$: T=VAL(T$): RETURN
2220 LOCATE 10,29: INPUT "",TE$           : RETURN
2230 LOCATE 12,29: INPUT "",ND$           : RETURN
2240 LOCATE 14,29: INPUT "",FT            : RETURN
2250 LOCATE 14,74: INPUT "",ME$           : RETURN
2260 '
2270 ' APAGA PARCIALMENTE A TELA
2280 '
2290 FOR A=B TO 15
2300   LOCATE A, 5: PRINT SPACE$(72)
2310 NEXT
2320 LOCATE 23,15: PRINT LBR$: RETURN
2330 '
2340 ' ROTINA DE DETECAO DE ERRO
2350 '
2360 RESTORE
2370 FOR P=1 TO 10
2380   READ ER%,EST$
2390   IF ERR=ER% THEN EAUX$=EST$: GOTO 2410 ELSE EAUX$="ERRO FATAL"
2400 NEXT P
2410 LOCATE 25,16: PRINT EAUX$;" NA LINHA:";ERL
2420 RESUME
2430 DATA 2,"ERRO DE SINTAXE"           "
2440 DATA 3,"RETURN SEM GOSUB"          "
2450 DATA 5,"PARAMETRO ILEGAL P/ UMA FUNCAO" "
2460 DATA 7,"O PROGRAMA E LONGO E TEM MTOS LACOS" "
2470 DATA 8,"REFERENCIA A UMA LINHA INEXISTENTE" "
2480 DATA 9,"SUBSCRITOR FORA DO LIMITE DA MATRIZ" "
2490 DATA 10,"REDEFINICAO DA MATRIZ"        "
2500 DATA 11,"DIVISAO POR ZERO"          "

```

```

2510     DATA 13,"TIPOS INCOMPATIVELIS"
2520     DATA 61,"DISCO CHEIO"
2530 '
2540 '
2550 '
2560 ET=20
2570 GOSUB 2260: EXT$="A.DAT"
2580 OPEN "D",#1,ND$+"X"+EXT$"
2590 OPEN "D",#2,ND$+"Y"+EXT$"
2600 FOR I=1 TO 20
2610   GOSUB 2750
2620 NEXT
2630 GOTO 1910
2640 '
2650 '
2660 '
2670 ET=8
2680 GOSUB 2260: EXT$="B.DAT"
2690 OPEN "D",#1,ND$+"X"+EXT$"
2700 OPEN "D",#2,ND$+"Y"+EXT$"
2710 FOR I=1 TO 8
2720   GOSUB 2750
2730 NEXT
2740 GOTO 1910
2750 '
2760 '
2770 '
2780 PRE$="X": G=1: IF ME$="S" THEN R$="N": GOTO 2820
2790 IF VA(1)<>0 THEN GOSUB 3540: W$=""
2800 LOCATE 23,20: PRINT "Posicione as ponteiras e tecle <ESC>"
2810 WHILE INKEY$<>CHR$(27): WEND
2820 IF VA(1)<>0 THEN GOSUB 3540
2830 LOCATE 23,15: PRINT "AGUARDE CARREGANDO OS PROGRAMAS"
2840 WRT$="GT 'P GND';": DISPO% = D4145B% : GOSUB 1030      "ESCREVE NO EQPTO
2850 TEMPO=4000: GOSUB 3270
2860 WRT$="MD ME1"           : GOSUB 1030      "ESCREVE NO EQPTO
2870 TEMPO=3000: GOSUB 3270
2880 WRT$="GT 'P LW"+PRE$+SU$+"':": GOSUB 1030      "ESCREVE NO EQPTO
2890 TEMPO=3000: GOSUB 3270
2900 LOCATE 23,15: PRINT "AGUARDE CARREGANDO OS PROGRAMAS"
2910 TEMPO=2000: WRT$="MD ME1"           : GOSUB 1030      "ESCREVE NO EQPTO
2920 GOSUB 3270
2930 LOCATE 23,15: PRINT SPACE$(50): SOUND 210,2
2940 FOR CNT=1 TO 5
2950   IF W$="R" THEN GOSUB 3670
2960   X$=INKEY$: IF X$<>"" THEN SOUND 220,2
2970   CALL IBRD(D347BA%,V1$)
2980   CALL IBRD(D347BB%,V2$)
2990   VA(CNT)=VAL(LEFT$(V1$,11)): VA(CNT)=VA(CNT)*FA
3000   VB(CNT)=VAL(LEFT$(V2$,11)): VB(CNT)=VB(CNT)*FT

```

```

3010      MA=(VA(1)+VA(2)+VA(3)+VA(4)+VA(5))/CNT
3020      MB=(VB(1)+VB(2)+VB(3)+VB(4)+VB(5))/CNT
3030      LOCATE 8,30: PRINT "MEDIDAS DO EIXO ";PRE$
3040      GOSUB 3410
3045      GOSUB 3260
3050      X$=INKEY$: IF X$<>"" THEN SOUND 220,2
3070      IF LNH=3070 THEN LNH=0: GOTO 3160
3080      NEXT
3090      IF X$="" AND W$="R" THEN XV=0:GOTO 2940 ELSE IF W$="R" THEN 3160
3100      VA=(VA(1)+VA(2)+VA(3)+VA(4)+VA(5))/5
3110      VB=(VB(1)+VB(2)+VB(3)+VB(4)+VB(5))/5
3120      IF ME$="S" OR ME$="s" THEN 3180
3130      LOCATE 23,15: INPUT "Repete a medida (s/N) ",R$
3140      IF R$="S" OR R$="s" THEN WRT$="ME2": GOSUB 1030: W$="R": GOTO 2940
3150      IF R$<>"N" AND R$<>"n" AND R$<>"" THEN 3130 ELSE W$="": GOTO 3170
3160      IF W$="R" THEN W$="": WRT$="ME4": GOSUB 1030 : GOTO 2900
3170      LOCATE 23,15: PRINT SPACE$(60)
3180      PRINT #G,USING "+####.###";VA,VB:; PRINT #G," ";TIME$
3190      IF PRE$="X" THEN G=2: PRE$="Y": GOTO 2820 ELSE RETURN
3200      LOCATE 23,15: PRINT LBR$
3210      RETURN
3220      '
3230      '
3240      ' ROTINA DE TEMPO
3250      '
3260      TEMPO=T*1000
3270      FOR X=1 TO TEMPO: NEXT
3280      GOTO 3690
3290      '
3300      '
3310      ' ROTINA DE CONVERSAO NUMERICA
3320      '
3330      AA=XAUX
3340      A=ABS(AA)
3350      B=0
3360      IF A=0 THEN RETURN
3370      IF A>=1000 THEN A=A/1000:B=B+3
3380      IF A<=.1 THEN A=A*1000:B=B-3
3390      IF A<1000 AND A>=.1 THEN XAUX=A*SGN(AA): AUX$=STR$(XAUX)+"E"+STR$(B): RETURN
3400      GOTO 3970
3410      '
3420      '
3430      ' TELA DE SAIDA DOS DADOS
3440      '
3450      LOCATE 8,55: PRINT "Arquivo ... ";ND$+PRE$+EXT$
3460      LOCATE 9,55: PRINT "Linha ....: ";I;" /";ET
3470      LOCATE 11, 5: PRINT "VOLTIMETRO B ...: ";:PRINT USING "+####.###";VB(CNT)
3480      LOCATE 11,45: PRINT "MEDIA VOLT B ...: ";:PRINT USING "+####.###";MB
3490      LOCATE 13, 5: PRINT "VOLTIMETRO A ...: ";:PRINT USING "+####.###";VA(CNT)
3500      LOCATE 13,45: PRINT "MEDIA VOLT A ...: ";:PRINT USING "+####.###";MA

```

```
3510 LOCATE 15, 5:PRINT "MEDIDA NUMERO .: ";CNT
3520 IF CNT=6 THEN LOCATE 8,67: PRINT SPACE$(10)
3530 RETURN
3540 '
3550 : LIMPA AS LEITURAS UTILIZADAS
3560 '
3570 BRO$=SPACE$(15): ERASE VA,VB
3580 LOCATE 8,67: PRINT SPACE$(10)
3590 LOCATE 8,45: PRINT SPACE$(4)
3600 LOCATE 9,67: PRINT SPACE$(10)
3610 LOCATE 11,23: PRINT BRO$:
3620 LOCATE 11,63: PRINT BRO$,
3630 LOCATE 13,63: PRINT BRO$-
3640 LOCATE 15,23: PRINT BRO$-
3650 LOCATE 13,23: PRINT BRO$-
3660 RETURN
3670 IF XV=0 THEN ERASE VA,VB : XV=1
3680 LOCATE 23,15: PRINT "TECLE ALGO PARA COMECAR AS MEDIDAS": RETURN
3690 '
3700 '
3710 '
3720 IF X$<>"" AND W$="R" THEN LNH=3070: RETURN ELSE RETURN
```